

# 2014 年度知的財産活動実態調査

The Survey on Intellectual Property-Related

Activities in Korea 2014

特許庁・貿易委員会

## 利用者のために

1. この報告書は韓国における企業及び大学・公共研究機関の知的財産活動の現状を把握するため、基準年度に産業財産権の出願及び登録の実績のある企業及び大学・公共研究機関を対象に 2014 年に実施した知的財産活動調査の結果を収録したものである。
2. この報告書に収録されている統計数値は標本調査の結果を基に母数推定 (parameter estimates) したものである。
3. 統計表の統計数値は全て四捨五入上の差異によって各項目の合計と総計が一致しない可能性があり、複数回答項目は構成比の合計が 100 を超過する。
4. 産業分類は 2007 年 12 月 28 日改正告示された第 9 次標準産業分類を適用している。それに従って 2007 年度知的財産活動調査結果と比べる時は業種分類の差異を認知した上で使用しなければならない。
5. この報告書で使用されている図と表の年度は別途表示が無い限り全て 2014 年度の調査結果を意味する。
6. この報告書の内容に関する問合せは韓国知識財産研究院の経済研究チーム (02-2189-2628/2629) が担当している。また、報告書の内容は韓国特許庁のホームページ (<http://www.kipo.go.kr>) または貿易委員会のホームページ (<http://www.ktc.go.kr>) でも確認することができる。

## <目次>

要約文.....	15
<b>第1章 調査の概要.....</b>	<b>32</b>
第1節 調査の目的及び沿革.....	32
1. 調査の目的.....	32
2. 調査沿革.....	32
第2節 調査質問事項及び標本設計.....	35
1. 調査質問事項の設計.....	35
2. 標本設計.....	38
第3節 調査方法及び結果.....	45
1. 調査方法.....	45
2. 調査結果.....	48
<b>第2章 企業の知的財産活動.....</b>	<b>52</b>
第1節 知的財産活動のインフラ.....	52
1. 知的財産担当組織及び人材.....	52
2. 知的財産担当人材に対する職務教育及び人件費・教育費.....	57
3. 知的財産サービスの活用状況.....	60

第2節 特許基盤の知的財産活動 .....	63
1. 先行特許(技術)調査など特許情報の活用 .....	63
2. 職務発明補償 .....	66
3. 技術取引機関、技術マーケティング会社との協力 .....	70
第3節 知的財産の創出及び活用 .....	75
1. 知的財産基礎統計情報及び情報システム .....	75
2. 外部からの知的財産導入実績及び今後の計画 .....	77
3. 保有知的財産の実査状況 .....	82
4. 知的財産権の売却/移転及び活用状況 .....	84
5. 効果的な知的財産の創出及び活用のために必要な政策支援 .....	87
第4節 知的財産の保護 .....	90
1. 予備評価の実施状況 .....	90
2. 研究開発成果の保護戦略 .....	93
3. 産業財産権の海外出願/登録及び国内出願計画 .....	95
4. 産業財産権の出願/審査/維持費用及び関連規定の状況 .....	98
5. 効果的な知的財産保護のために必要な政策支援 .....	102
第5節 知的財産の侵害及び紛争 .....	103
1. 知的財産権侵害及び被害規模 .....	103
2. 知的財産権侵害に対する対応状況 .....	117
3. 知的財産権侵害被害に対する紛争対応の結果 .....	126



4. 知的財産権侵害及び紛争関連の問題及び必要な政策支援.....	130
-----------------------------------	-----

### 第3章 大学及び公共研究機関の知的財産活動 ..... 139

第1節 知的財産活動インフラ .....	139
----------------------	-----

1. 知的財産担当組織及び人材 .....	139
-----------------------	-----

2. 知的財産担当人材に対する職務教育及び人件費・教育費.....	142
-----------------------------------	-----

3. 知的財産サービスの活用及び総合的な管理システムの構築状況	145
---------------------------------	-----

第2節 特許基盤の知的財産活動 .....	149
-----------------------	-----

1. 先行特許(技術)調査など特許情報の活用.....	149
-----------------------------	-----

2. 職務発明補償 .....	152
-----------------	-----

3. 技術取引機関、技術マーケティング会社との協力.....	155
--------------------------------	-----

第3節 知的財産の創出及び活用活動 .....	159
-------------------------	-----

1. 知的財産基礎統計情報及び情報システム.....	159
----------------------------	-----

2. 知的財産を創出するための研究開発活動及び今後の戦略.....	160
-----------------------------------	-----

3. 保有知的財産の実査状況 .....	161
----------------------	-----

4. 知的財産権の売却・移転及び活用状況.....	164
---------------------------	-----

5. 効果的な知的財産の創出及び活用のために必要な政策支援...	167
----------------------------------	-----

第4節 知的財産の保護 .....	169
-------------------	-----

1. 予備評価実施状況 .....	169
-------------------	-----

2. 研究開発成果の保護戦略.....	171
---------------------	-----

3. 産業財産権の海外出願/登録及び国内出願計画.....	173
-------------------------------	-----

4. 産業財産権の出願/審査/維持費用及び関連規定の状況.....	176
5. 効果的な知的財産保護のために必要な政策支援.....	177
第5節 知的財産の侵害及び紛争 .....	178
1. 知的財産権の侵害及び事後対応.....	178
2. 知的財産権侵害及び紛争関連の問題及び必要な政策支援.....	179
<b>第4章 2014年韓国知的財産活動の年度別傾向 .....</b>	<b>182</b>
1. 知的財産担当組織及び人材保有比率の改善.....	182
2. 知的財産先行活動の変化.....	184
3. 外部からの知的財産導入の改善.....	187
4. 知的財産の活用及び事業化比率の増加.....	188
5. 知的財産保護戦略の変化.....	189
6. 知的財産権侵害類型の特徴.....	192
用語整理.....	198
<付録1>業種分類と韓国標準産業分類表(KSIC)との連結	201
<付録2>調査票：企業.....	203
<付録3>調査票：大学・公共研究機関.....	240

## <表目次>

[表 1. 1] 知的財産活動の分類 .....	36
[表 1. 2] 知的財産活動実態調査の主要調査項目 .....	37
[表 1. 3] 既存知的財産権侵害実態調査と母集団の比較 .....	39
[表 1. 4] 年度別母集団の規模 .....	40
[表 1. 5] 企業母集団の分布 .....	40
[表 1. 6] 大学・公共研究機関の母集団の分布 .....	41
[表 1. 7] 企業登録件数別の全数調査対象の比率 .....	42
[表 1. 8] 企業標本の分布 .....	43
[表 1. 9] 2 段階アンケート調査のプロセス及び方法 .....	45
[表 1. 10] 調査拒否及び杜撰な回答である時の対応策 .....	46
[表 1. 11] 回答が無い場合の対応策及び欠測値の補正方法 .....	47
[表 1. 12] 有効標本の規模及び回答率 .....	48
[表 1. 13] 業種別有効標本の規模及び回答率 .....	49
[表 1. 14] 業種別、企業類型別回答企業の分布 .....	49
[表 1. 15] 大学・公共(研)類型別回答機関の分布 .....	50
[表 2. 1] 職務教育の実施を希望する場合、扱うべき内容 .....	58
[表 2. 2] 知的財産担当者の人件費及び教育費の状況 .....	60
[表 2. 3] 知的財産サービスの利用状況 .....	61
[表 2. 4] 職務発明補償類型別の実施比率 .....	68
[表 2. 5] 全体特許出願件数による職務発明補償規定の保有比率 .....	69
[表 2. 6] 国内技術取引システムの活用度 .....	72
[表 2. 7] 最近 3 年間外部から知的財産を導入した企業の比率 .....	79
[表 2. 8] 回答企業が保有している特許の活用件数及び事業化件数、比率 .....	87
[表 2. 9] 効果的な知的財産創出のための政策支援の必要性 .....	88
[表 2. 10] 効果的な知的財産活用のための政策支援の必要性 .....	89
[表 2. 11] 研究開発成果保護戦略の活用度 .....	94
[表 2. 12] 2014 年対比 2015 年の知的財産権出願計画 .....	97
[表 2. 13] 産業財産権の国内出願増減に影響を及ぼす要因 .....	97

[表 2. 14] 知的財産の出願・審査・維持費用 .....	99
[表 2. 15] 効果的な知的財産保護のための政策支援の必要性 .....	102
[表 2. 16] 出願規模別の特許侵害比率 .....	105
[表 2. 17] 出願規模別の商標権侵害比率 .....	106
[表 2. 18] 産業財産権出願規模別の実際被害金額が発生した企業の比率 .....	116
[表 2. 19] 産業財産権出願規模別の未実現金額発生企業の比率 .....	117
[表 2. 20] 全体侵害被害規模の推定 .....	117
[表 2. 21] 産業財産権出願規模別の損害賠償金または被害金額発生企業の比率 .....	126
[表 2. 22] 損害賠償額または和解金の規模推定 .....	127
[表 2. 23] 知的財産権侵害対応における問題 .....	131
[表 2. 24] 知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策 .....	131
[表 2. 25] 輸出入の比較による知的財産権侵害対応時の問題 .....	133
[表 2. 26] 輸出入の比較による知的財産権侵害対応のために必要な政府政策 .....	133
[表 2. 27] 知的財産権の侵害及び紛争、保護関連の政府支援政策及び制度 .....	136
[表 3. 1] 職務教育の実施を希望する場合、取り扱うべき内容 .....	143
[表 3. 2] 知的財産担当者の人件費及び教育費の状況 .....	145
[表 3. 3] 知的財産サービスの利用状況 .....	146
[表 3. 4] 職務発明補償類型別の実施比率 .....	154
[表 3. 5] 国内技術取引システムの活用度 .....	157
[表 3. 6] 効果的な知的財産創出のための政策支援の必要性 .....	167
[表 3. 7] 効果的な知的財産活用のための政策支援の必要性 .....	168
[表 3. 8] 2014 年対比 2015 年の知的財産権出願計画 .....	174
[表 3. 9] 産業財産権の国内出願の増減に影響を及ぼす要因 .....	175
[表 3. 10] 知的財産の出願・審査・維持費用 .....	176
[表 3. 11] 効果的な知的財産保護のための政策支援の必要性 .....	177
[表 3. 12] 知的財産権侵害の対応における問題 .....	179
[表 3. 13] 知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策 .....	180

## ○図目次

[図 2.1] 知的財産担当組織の保有状況	53
[図 2.2] 知的財産担当組織総括者の地位	53
[図 2.3] 知的財産担当人材の保有状況	54
[図 2.4] 知的財産関連業務を行っている企業の割合	55
[図 2.5] 知的財産専門担当人材の採用予定比率	56
[図 2.6] 知的財産権担当人材に対する職務教育の状況及び必要性	58
[図 2.7] 知的財産人材の能力を高めるために必要な政府政策	59
[図 2.8] 知的財産サービス提供機関別の利用比重	62
[図 2.9] 先行特許(技術)調査の実施状況	63
[図 2.10] 先行特許(技術)調査の必要性	64
[図 2.11] 出願件数別の先行特許(技術)調査の必要性	64
[図 2.12] 先行特許(技術)調査を行う場合の遂行人材	65
[図 2.13] 職務発明補償規定の保有及び活用状況	66
[図 2.14] 職務発明補償規定を保有していない場合、その主な理由	67
[図 2.15] 職務発明補償規定の保有企業及び未保有企業の知的財産活動状況	69
[図 2.16] 最近3年間技術取引機関に対する業務依頼及び締結状況	71
[図 2.17] 技術取引機関などに業務を依頼した場合の主な費用支給方法	72
[図 2.18] 特許技術の事業化における最大の問題点	74
[図 2.19] 知的財産基礎統計情報の活用状況	75
[図 2.20] 企業類型別の知的財産情報システムの活用	76
[図 2.21] 出願規模別の知的財産情報システムの活用	77
[図 2.22] 国内知的財産導入企業の比率及び平均導入件数	78
[図 2.23] 知的財産を導入した企業の類型別導入件数	79
[図 2.24] 知的財産導入を拡大する予定の企業比率	80
[図 2.25] 知的財産導入に向けた投資拡大の方向	81
[図 2.26] 知的財産実査の実施状況	82

[図 2.27] 知的財産実査の必要性 .....	83
[図 2.28] 知的財産実査を行っている場合の遂行人材 .....	83
[図 2.29] 知的財産の売却・移転状況 .....	85
[図 2.30] 知的財産の売却または移転する上で最大の問題点 .....	86
[図 2.31] 特許権の活用率及び事業化率 .....	86
[図 2.32] 産業財産権出願前の社内予備評価の実施状況 .....	90
[図 2.33] 予備評価実施の必要性 .....	91
[図 2.34] 予備評価を行っている場合の実行人材 .....	92
[図 2.35] 研究開発成果保護戦略の活用比率及び活用度 .....	93
[図 2.36] 公式的/非公式的な権利保護の比率 .....	94
[図 2.37] 国内知的財産保護水準に対する意見 .....	95
[図 2.38] 特許権の海外出願/登録企業の比重 .....	96
[図 2.39] 企業類型別の特許権海外出願及び登録企業の比重 .....	96
[図 2.40] 営業秘密の管理及び技術流出防止指針の保有・遵守状況 .....	100
[図 2.41] 営業秘密管理及び技術流出のための人的管理状況 .....	101
[図 2.42] 営業秘密管理及び技術流出防止のための物的管理状況 .....	101
[図 2.43] 企業類型別の知的財産権侵害の被害比率 .....	103
[図 2.44] 出願件数別の知的財産権侵害の被害比率 .....	104
[図 2.45] 産業財産権類型別の侵害被害件数 .....	104
[図 2.46] 企業類型別の産業財産権侵害の被害比率 .....	105
[図 2.47] 各権利別業種による侵害比率の特徴 .....	106
[図 2.48] 権利類型別の被害状況 .....	107
[図 2.49] 産業財産権出願規模別の全体侵害事例のうち特許権侵害の比重 .....	108
[図 2.50] 侵害製品製造者別の被害状況 .....	109
[図 2.51] 産業財産権出願規模別の侵害製品製造者の類型別比率 .....	110
[図 2.52] 侵害製品製造地域別の被害状況 .....	110
[図 2.53] 産業財産権出願規模別の侵害製品製造地域の比率 .....	111
[図 2.54] 侵害製品流通地域別の被害状況 .....	112
[図 2.55] 侵害製品の流通類型及び被害状況 .....	113

[図 2.56] 侵害製品発見経路別の被害状況 .....	113
[図 2.57] 知的財産権侵害の被害が発生した主な原因 .....	114
[図 2.58] 実際被害金額の規模 .....	115
[図 2.59] 未実現被害金額の規模 .....	116
[図 2.60] 知的財産権侵害への対応比率 .....	118
[図 2.61] 知的財産権侵害における対象別の対応法 .....	119
[図 2.62] 企業類型別の国内企業に対する侵害対応法 .....	120
[図 2.63] 企業類型別の海外企業に対する侵害対応法 .....	121
[図 2.64] 侵害製品の流通類型別の対応状況 .....	121
[図 2.65] 各対応類型別の対応活動を行わなかった理由 .....	122
[図 2.66] 企業類型別の対応活動(行政機関に知的財産権侵害製品に対する 取締り及び侵害事実に対する調査要請)を行わなかった理由 .....	123
[図 2.67] 企業類型別の対応活動(告訴・告発、仮処分、民・刑事訴訟など 司法的な救済措置の申請)を行わなかった理由 .....	123
[図 2.68] 企業類型別の対応活動(侵害企業に警告または示談の提案など独 自対応)を行わなかった理由 .....	124
[図 2.69] 知的財産権侵害対応費用 .....	125
[図 2.70] 他企業などから侵害警告を受けたり、訴訟が提起された比率 .....	125
[図 2.71] 損害賠償額または和解金の規模 .....	126
[図 2.72] 輸出入の有無による侵害被害企業の比率 .....	128
[図 2.73] 輸出入の有無による産業財産権類型別の侵害被害比率 .....	128
[図 2.74] 輸出入の有無による知的財産権侵害への対応比率 .....	129
[図 2.75] 輸出入の有無による他企業からの警告または訴訟提起の状況 .....	129
[図 2.76] 輸出入の有無による侵害対応の依頼機関 .....	130
[図 3.1] 知的財産担当組織の状況 .....	139
[図 3.2] 知的財産専門担当人材の保有状況 .....	140
[図 3.3] 知的財産担当者の主要業務 .....	141
[図 3.4] 知的財産担当人材の採用計画 .....	142
[図 3.5] 知的財産権担当人材に対する職務教育の状況及び必要性 .....	143
[図 3.6] 知的財産人材の能力強化のために必要な政府政策 .....	144

[図 3. 7] 知的財産サービス提供機関別の利用比重 .....	147
[図 3. 8] 知的財産管理システムの構築及び活用状況 .....	148
[図 3. 9] 知的財産管理システムの構築費用 .....	148
[図 3. 10] 先行特許(技術)調査の状況 .....	149
[図 3. 11] 先行特許(技術)調査の必要性 .....	150
[図 3. 12] 先行特許(技術)調査を行う場合の実行人材 .....	151
[図 3. 13] 先行特許(技術)調査に対する機関の支援 .....	152
[図 3. 14] 職務発明意補償規定の保有及び活用状況 .....	152
[図 3. 15] 職務発明補償規定を保有していない場合その主な理由 .....	153
[図 3. 16] 職務発明補償規定の保有・未保有機関における産業財産権の活用 比率 .....	155
[図 3. 17] 最近 3 年間技術取引機関への業務依頼及び締結の状況 .....	156
[図 3. 18] 技術取引機関などに業務を依頼した場合の主な費用支給方法 .....	156
[図 3. 19] 知的財産基礎統計情報の活用状況 .....	159
[図 3. 20] 優秀な知的財産を創出するための活動及び戦略 .....	160
[図 3. 21] 知的財産実査の実施状況 .....	162
[図 3. 22] 知的財産実査の必要性 .....	163
[図 3. 23] 知的財産実査を行っている場合、その実施人材 .....	164
[図 3. 24] 知的財産を売却/移転した機関の比率及び件数 .....	165
[図 3. 25] 特許権の総保有件数対比活用件数の比率 .....	166
[図 3. 26] 特許権未活用の理由 .....	166
[図 3. 27] 産業財産権の出願などに先行して行う予備評価の実施状況 .....	169
[図 3. 28] 予備評価実施の必要性 .....	170
[図 3. 29] 予備評価を実施している場合の実施人材 .....	171
[図 3. 30] 研究開発成果保護戦略の活用比率及び活用度 .....	171
[図 3. 31] 公式的/非公式的な権利保護の比率 .....	172
[図 3. 32] 現在国内知的財産保護水準に対する認識 .....	173
[図 3. 33] 特許権の海外出願及び登録の比重 .....	174
[図 3. 34] 知的財産権侵害の事後対応 .....	179
[図 4. 1] 知的財産担当組織保有比率の推移 .....	182



[図 4. 2] 専担人材の保有比率及び専担人材数の推移	183
[図 4. 3] 知的財産担当人材職務教育の実施状況	184
[図 4. 4] 企業の先行活動実施比率の推移	185
[図 4. 5] 大学及び公共(研)の先行活動実施比率の推移	185
[図 4. 6] 全体研究開発課題、発明、保有知的財産のうち実施比率の変化	186
[図 4. 7] 先行活動の必要性に対する認識の変化	187
[図 4. 8] 知的財産導入の推移	187
[図 4. 9] 知的財産導入拡大方向の変化	188
[図 4. 10] 全体特許保有件数対比の活用率及び事業化率	189
[図 4. 11] 権利保護手続きの進行比率	190
[図 4. 12] 国内知的財産保護水準強化の必要性	191
[図 4. 13] 海外出願及び登録の推移	192
[図 4. 14] 知的財産権の侵害比率	193
[図 4. 15] 製造地域別の侵害被害比率	194
[図 4. 16] 流通地域別の侵害被害比率	195
[図 4. 17] 損害賠償額または和解金が発生した企業の比率	196

## 要約文 →

- I. 調査の目的及び沿革
- II. 主要調査結果

# 要約文

## I. 調査の目的及び沿革

### 1. 必要性及び目的

- 知的財産政策を効率的に樹立・推進するため、各企業、大学・公共研究機関の活動状況を総合的に把握及び分析できる統計資料が必要
- 知識財産基本法第31条に基づき、知的財産の創出・保護・活用と侵害などの状況について「知的財産活動実態調査」を実施

### 2. 統計作成の沿革

- 2006年：企業を対象に知的財産活動調査を実施
  - 法的根拠：統計法による政府承認統計(第13802号、「知的財産活動調査」)
- 2007年：調査対象を大学・公共(研)まで拡大
  - 名称の変更：知的財産活動実態調査(The Survey of Intellectual Property-Related Activities)
  - 知的財産活動の段階別先行活動に対する質問事項などを細分化
- ～2010年：ニーズによって調査項目を修正するなど改善活動を展開
- 2011年：調査領域の拡大及び法的根拠の確保
  - 知識財産基本法による法的根拠の確保
  - 被害・侵害状況に対する調査領域の拡大
  - 貿易委員会の「知的財産権侵害実態調査」と統合

□2012～2013年：知的財産の範囲及びニーズによって調査項目を修正するなど改善活動を展開

□2014年：調査の信頼性を高めるための標本設計の精巧化及び調査票の改善活動を展開

### 3. 調査概要

□調査期間：2014. 7. 16～2014. 10. 14(約3ヶ月)

□調査標本の設計

○2014年を基準に、基準年度(出願2011年と2012年、登録2009年～2013年)に産業財産権を2件以上出願し、1件以上登録した国内20,799の企業及び大学・公共研究機関

\*ここで産業財産権とは特許、実用新案、デザイン、商標を全て含める

(単位：個)

	母集団の大きさ	企業	大学及び公共(研)
2007年	10,202	10,050	152
2008年	11,470	11,292	178
2009年	11,987	11,792	195
2010年	13,392	13,165	227
2011年	17,440	17,220	220
2012年	18,656	18,418	238
2013年	20,795	20,566	229

2014年	20,799	20,569	230
-------	--------	--------	-----

○企業の場合、産業財産権の出願規模(共通)と業種(企業)を基準に26の集団に層化してランダム抽出

－基準年度に年平均出願10件以上または5年間登録100件以上の企業は**全数調査**

－基準年度に年平均出願10件未満、そして5年間登録100件未満の企業などに対しては**標本調査**を実施

※抽出率10%で標本抽出

－全体標本数：3,825(1,965は全数調査、1,860は標本調査)

○大学及び公共研究機関の場合は出願及び登録件数に関係なく**全数調査**を実施

□標本誤差：95%信頼水準に±2.75%

○標本誤差の推定式

$$1.96 \times \sqrt{\{(1 - (n/N)) \times (P(1 - P)/n)\}}$$

※nは標本数、Nは母集団の数であり、Pは(最大許容誤差)母比率である。

□回答率：46.7%(企業43.4%、大学・公共(研)90.3%)

○企業全数層の回答率40.7%、標本層の回答率45.9%

□母数推定(Parameter Estimates)

○抽出された標本調査の結果と層化された各集団の母集団加重値を利用し、母集団に対する推定結果をともに提示、また全数調査の場合も回答率を調整するため加重値を利用して母数を推定する。

□調査項目

○知的財産活動の基盤となるインフラ領域と特許基盤の知的財産活動分野、知的財産活動の創出及び活用活動、知的財産の権利化及び保護活動、知的財産権の侵害及び紛争に関する事項に区分する。

## Ⅱ. 主要調査結果

### 1. 知的財産活動のためのインフラ

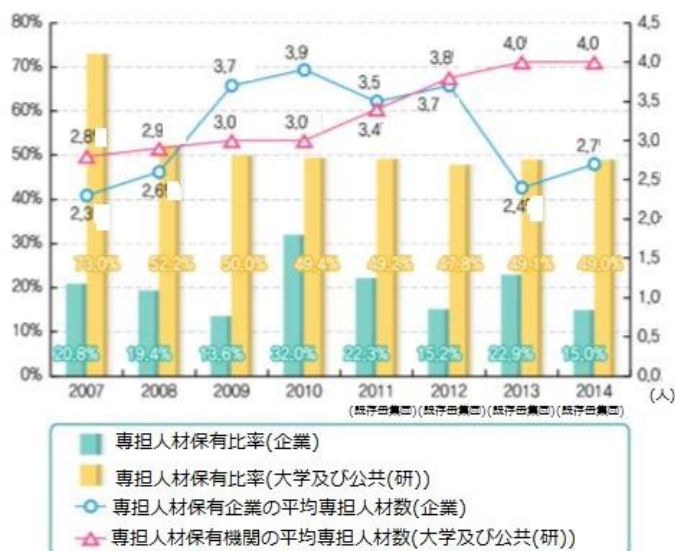
#### インフラ

#### 知的財産担当組織及び人材



□知的財産担当組織の保有比率は企業の場合 69.3% (76.5%)<sup>1</sup>で前年に比べて増加、大学・公共(研)は94.0% (95.5%)で小幅減少。

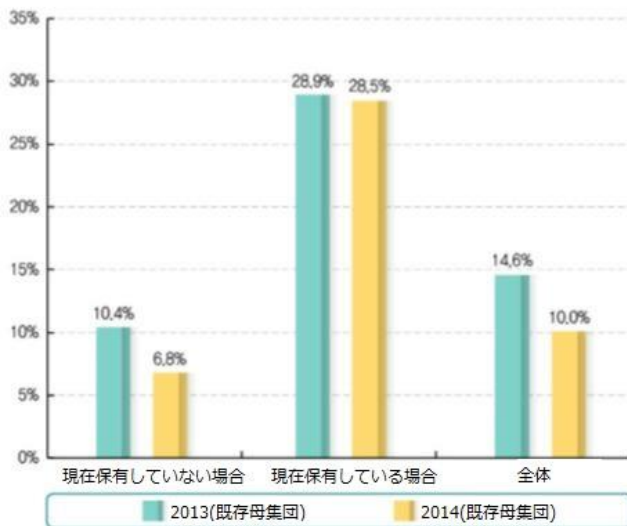
○企業の場合、独立専門担当部署の保有比率は 5.3% (6.8%) から 4.7% (5.3%)へと減少したが、兼任部署の保有比率が 53.7% (62.6%) から 64.6% (71.2%)へと増加



□知的財産を専門的に担当している人材の保有比率は企業12.8% (15.0%)、大学・公共(研)48.8% (49.0%)で前年比減少。

□知的財産の専門担当人材を保有する企業及び機関の平均専任人材数は企業の場合 2.6 人(2.7 人)で前年比増加、大学・公共(研)は 4.0 人(同一)で同水準を維持。

<sup>1</sup> 年度別の比較では2010年と母集団を同じく構成した場合の母集団推定値を入れている。括弧の中の数値は既存母集団の推定値である。



<知的財産担当人材の採用計画(企業)>

<知的財産担当者の人件費/教育費>

(単位：万ウォン)

区分	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年 (既存母 集団)	2012年 (既存母 集団)	2013年 (既存母 集団)	2014年 (既存母 集団)
企業	3,529	4,936	4,810	4,654	3,526	2,731	4,346	3,177
大学・ 公共(研)	1億 9,225	7,687	6,091	5,153	6,754	8,574	9,993	9,167

□知的財産専門担当人材を採用する予定のある比率は企業 9.1 % (10.0%)、大学・公共(研)25.5% (同一)で前年比減少。

□1年間支出した知的財産担当者への人件費/教育費は企業が2,731(3,177)万ウォン、大学・公共(研)9,061(9,167)万ウォンで前年比減少。

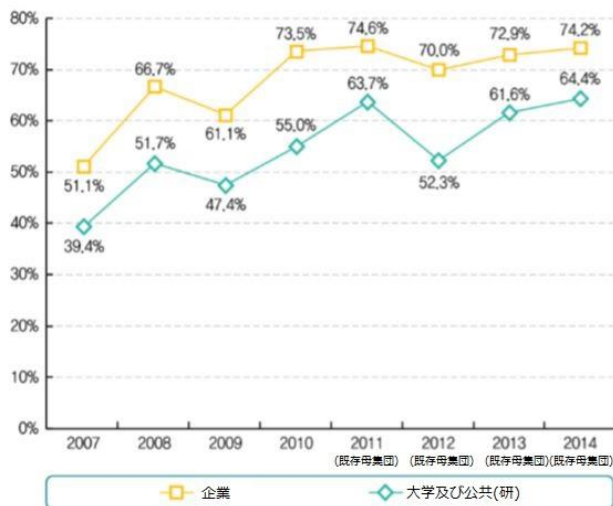
- 企業における知的財産インフラのレベルは全般的に着実に強化傾向。
  - 企業の担当組織保有比率は前年比増加。
  - 専門担当人材を保有する企業の平均専門担当人材数の増加。
- 大学及び公共(研)の場合、専門担当人材を保有する比率は小幅減少したが、高いインフラレベルを保ちつつある。
- 知的財産担当人材に関する今後の採用計画及び知的財産担当者に対する人件費/教育費の場合は多少減少。



## 2. 特許基盤の知的財産活動

### 特許基盤活動

### 先行特許(技術)調査活動の状況



□先行特許(技術)調査を行う企業の比率は74.2%、大学・公共(研)の比率は64.4%で前年比増加。

□企業の場合、先行特許(技術)調査が必要であると認識している比率が増加。

### 特許基盤活動

### 職務発明補償規定の保有状況

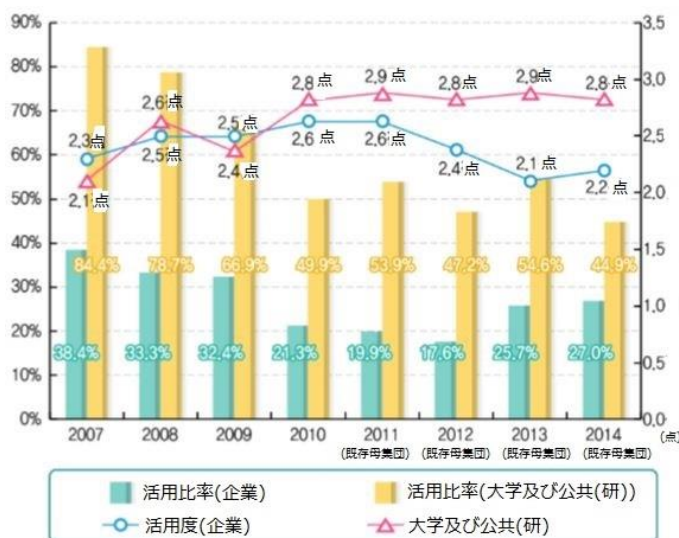


□職務発明補償規定を保有・活用する企業は41.7%で前年比増加、大学・公共(研)は93.5%で前年比小幅減少。

□国内特許登録補償と出願補償を実施する企業の比率は其々89.8%、77.7%である。

## 特許基盤活動

## 技術取引システムの利用状況



□オンライン技術取引システムの活用比率は企業 27.0%で前年比増加、大学・公共(研)は 44.9%で前年比減少。

□オンライン技術取引システムの活用度もまた企業の場合 2.2点で前年比増加、大学・公共(研)は 2.8点で小幅減少。

## 特許基盤活動

## 2013年特許に基づく知的財産活動の特徴

□企業及び大学・公共(研)の先行特許(技術)調査活動は着実に増加する傾向である。

○企業の場合 1.3%p 増加、大学・公共(研)の場合 2.8%p 増加。

□企業及び大学・公共(研)の職務発明補償制度の保有比率もまた着実に増加、もしくは高い水準を維持する傾向である。

○企業の場合職務発明補償制度の保有及び活用比率が 6.6%p 増加。

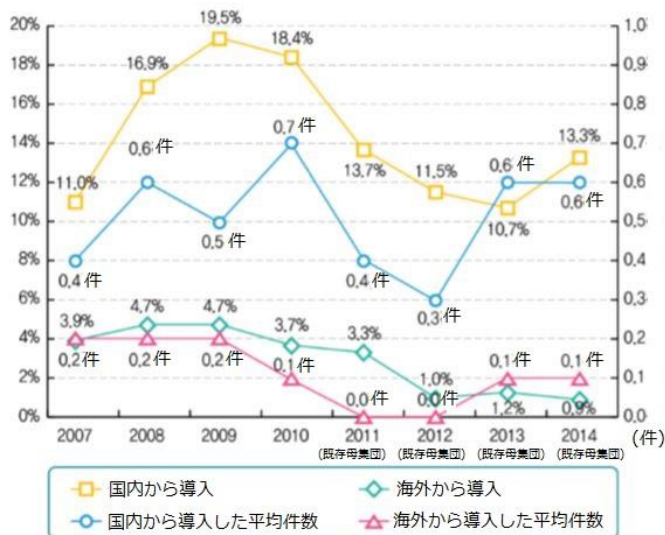
○大学・公共(研)の場合 1.6%p 小幅減少したが、全般的に高い比率を維持。

□特許に基づく知的財産活動は企業及び大学・公共(研)ともに全般的に強化されつつある。

### 3. 知的財産の創出及び活用活動

#### 創出及び活用

#### 外部知的財産の導入状況



□国内知的財産を導入した企業の比率は 12.0% (13.3%) で前年比増加。

○平均導入件数は 0.5 件 (0.6 件) で前年比同水準を維持。

□海外知的財産を導入した企業の比率は多少減少、平均導入件数は同水準を維持。

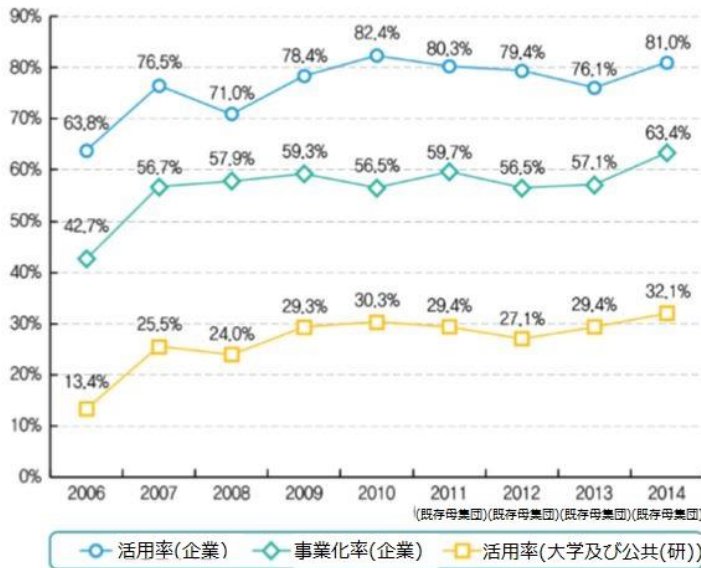
#### 創出及び活用

#### 保有知的財産の実査及び評価状況



□知的財産実査(評価)を行う比率は企業 27.9% (36.0%)、大学・公共(研)53.7% (54.6%) で前年比増加。

□保有している知的財産に対する実査及び評価活動が必要と回答した比率は企業と大学・公共(研)ともに多少減少。



□企業が保有する特許全体に比べて特許を活用した比率及び事業化した比率は 81.6% (81.0%)と 64.8% (63.4%)で前年比増加し、大学・公共(研)の活用比率もまた 32.1% (同一)で前年比増加。

- 企業と大学・公共(研)ともに知的財産の創出及び活用活動は改善されつつある。
- 1件以上国内から外部知的財産を導入した比率が増加。
- 知的財産の実査を行う比率及び特許を活用する比率が企業と大学・公共(研)ともに増加傾向。

## 4. 知的財産の保護

### 保護

### 予備評価の実施状況



□ 予備評価の実施比率は企業の場合 29.7% (36.6%) で前年比小幅減少、大学・公共(研)の場合には 60.9% (62.3%) で前年比増加。

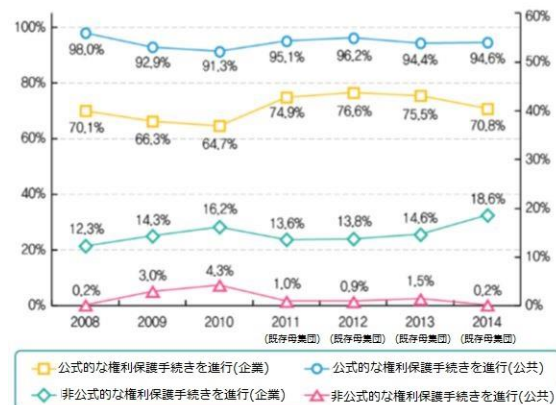
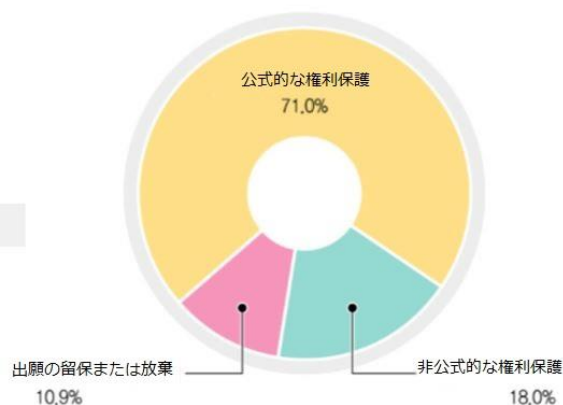
□ 予備評価の必要性に対する認識度は企業の場合前年比増加、大学・公共(研)の場合前年比減少。

### 保護

### 産業財産権の出願比率及び保護水準に対する認識

□ 企業と大学・公共(研)が産業財産権の出願など公式的な権利保護プロセスを踏む平均比率は全体発明のうち其々 71.0% (70.8%) と 94.7% (94.6%) で、企業の場合は小幅減少したが、大学・公共(研)の場合小幅増加。

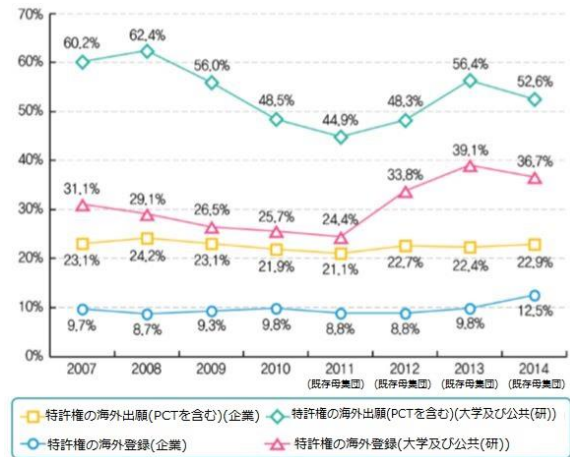
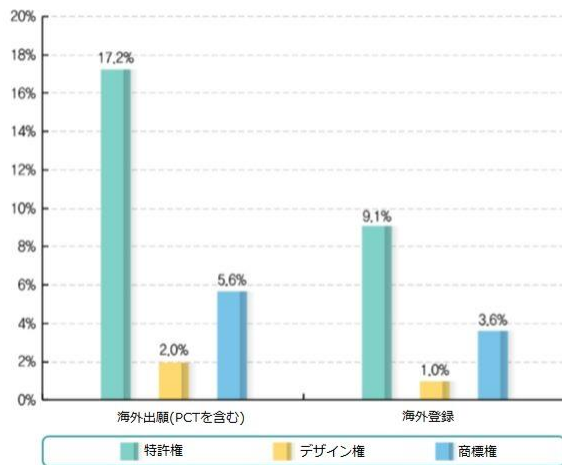
□ 企業と大学・公共(研)が非公式的な権利保護プロセスを踏む平均比率は其々 18.0% (18.6%) と 0.2% (同一) で企業の場合は前年比増加したが、大学・公共(研)の場合は減少。



< 権利保護手続きの進行比率(企業) >

□2013 年の 1 年間特許権を海外出願した企業は 17.2% (22.9%)、海外登録した企業は 9.1% (12.5%) で前年比増加。

□2013 年の 1 年間特許権を海外出願した大学・公共(研)は 51.3% (52.6%)、海外登録した大学・公共(研)は 36.1% (36.7%) で前年比減少。



< 海外出願及び登録 (PCT を含む) 状況 (企業) >

□企業における特許権の海外出願及び登録 (PCT を含む) 比率が増加し、非公式的な権利保護比率が増加するなど知的財産保護に向けた活動が全般的な強化。

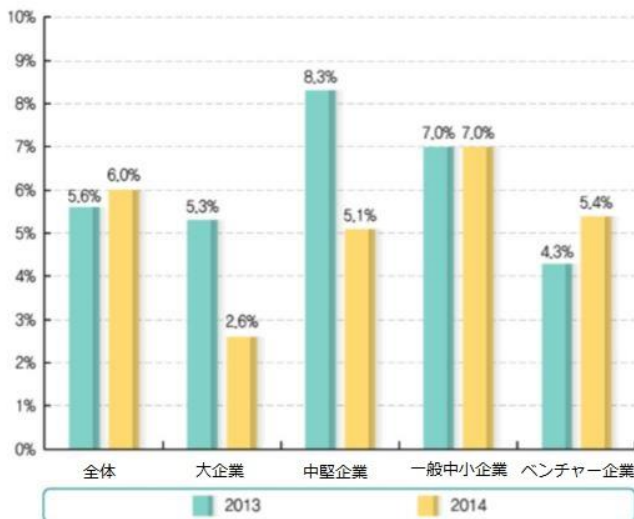
□大学・公共(研)の場合は公式的に権利保護プロセスを踏む比率が増加し、予備評価の実施比率が増加するなど保護活動が全般的に強化されたが、海外出願及び登録 (PCT を含む) 比率は多少減少。



## 5. 知的財産侵害及び紛争への対応

### 侵害及び紛争

### 知的財産侵害の比率

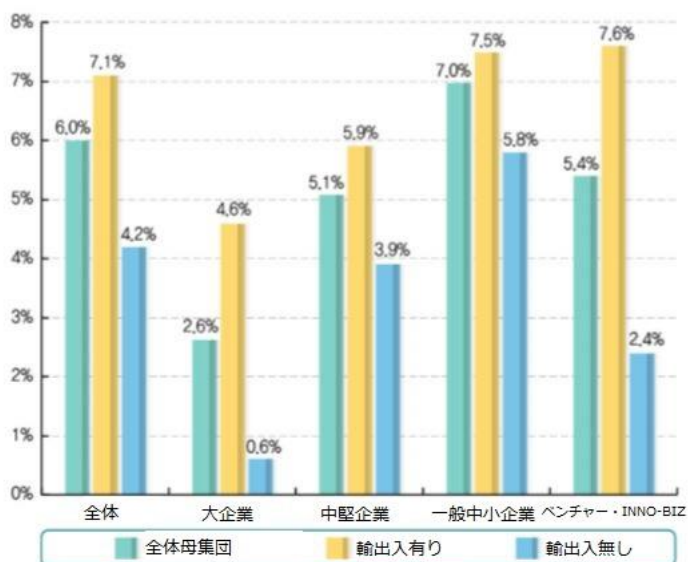


□ 1 件以上の知的財産権侵害を受けた企業の比率は 6.0% で前年比 0.4%p 増加

○ ベンチャー企業の場合は特に前年比 1.1%p 増加

### 侵害及び紛争

### 輸出入の有無による侵害比率

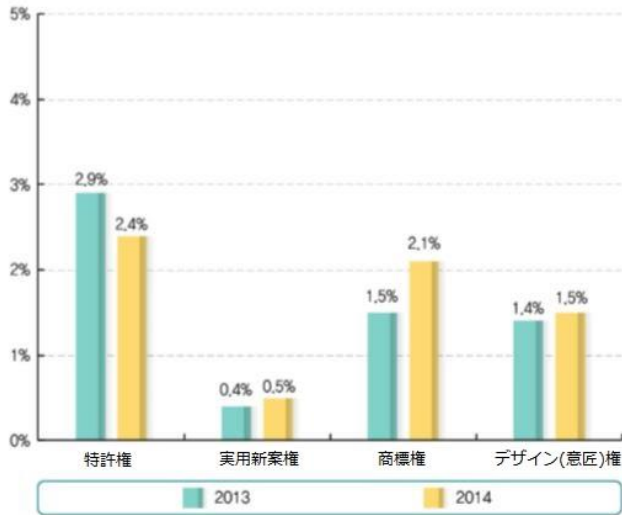


□ 輸出入企業の知的財産侵害比率は 7.1%

○ 輸出入業績のない企業の侵害比率は 4.2% で輸出入企業の侵害経験比率が高い。

## 侵害及び紛争

## 産業財産権類型別の侵害比率



□類型別の平均侵害比率の場合は実用新案権、商標権、デザイン権、全て前年比増加傾向。

○特許権の場合は多少減少したが、ベンチャー企業の場合は前年比1.3%p増加

## 侵害及び紛争

## 産業財産権類型別の侵害件数



□類型別の平均侵害件数の場合は特許権、実用新案権、デザイン権、全て増加。

○商標権の場合は平均件数が多少減少したが、ベンチャー企業の場合はまた前年比0.1件増加。



## 侵害及び紛争

## 損害賠償金または示談金が発生した比率



損害賠償額または示談金(億ウォン)			
合計		平均金額	
2013	2014	2013	2014
530	764	1.7	2.2

□企業が民事訴訟を通じて損害賠償額が認められる、もしくは示談が成立した比率は 36.1% で前年比 15.6%p 増加。

○最近 3 年間損害賠償額または示談金が発生した企業の比率は持続的に増加

○損害賠償額または示談金の総額及び平均金額もまた前年比其々 234 億ウォン、0.5 億ウォン増加

## 侵害及び紛争

## 侵害紛争の対応における問題点

□侵害紛争に対応する際、過剰な時間と費用が費やされることに対する負担が大きいものと見られ、輸出入業績のない企業が相対的に侵害の対応に難航しているものと見られる。

侵害対応における問題点	比率 (%)		
	全体	輸出入有り	輸出入無し
知的財産権法規など関連事項に対する情報不足	53.2	41.6	73.7
内部人材の専門性不足による関連知識の習得が難しい	55.1	40.5	81.6
紛争対応関連の政府支援政策の不足または情報不足	47.9	46.9	53.1
紛争対応のための法律代理人の選定が難しい	37.1	31.1	48.4
紛争対応の際、過剰な時間と費用が費やされる	81.1	73.4	98.0
知的財産権保護に向けた行政的・司法的救済手続きの不備	63.5	53.4	86.9

## 侵害及び紛争

## 侵害対応に向けた政府政策

□侵害対応に向けた政府政策の必要性に対しては輸出入の有無による差が大きくなり、実効性のある行政的・司法的処罰措置の強化に向けた政府の取り組みが求められる。

侵害対応に向けた政府政策	比率(%)		
	全体	輸出入 有り	輸出入 無し
実効性のある行政的・司法的処罰措置の強化	67.6	67.3	69.4
迅速な権利救済のための水際措置対象の知的財産権範囲を拡大、侵害物品の国内流入をシャットアウト	66.0	66.4	65.5
知的財産権の保護及び対応活動のための情報提供	63.4	63.6	66.2
行政機関の知的財産権侵害製品の取締権限の強化	62.6	62.0	64.8
知的財産権侵害製品などに対する通報褒賞金額の増額	55.6	55.3	56.8
知的財産権侵害対応のための訴訟など費用の支援	66.3	66.9	65.9
侵害及び知的財産権の有効性判断機関の一元化	64.1	63.9	66.3

## 侵害及び紛争

## 2013年侵害及び紛争対応活動の特徴

□知的財産価値の増加及び侵害に対する認識向上による侵害比率の増加傾向にある。

○技術に基づくベンチャー企業及び小規模出願企業の侵害被害も増加傾向にある。

□紛争の際に過剰な時間と費用が費やされることによる企業の負担増、技術に基づく小規模企業の侵害被害の増加によって、政府の政策的な支援が求められる。

# 第1章 調査の概要

第1節 調査の目的及び沿革

第2節 調査質問事項及び標本設計

第3節 調査方法及び結果

# 第1章 調査の概要

## 第1節 調査の目的及び沿革

### 1. 調査の目的

知的財産関連の統計は企業や大学、公共研究機関が知的財産と関連する意思決定や未来戦略の樹立において合理的な判断の根拠を提供する手段である。また、知的財産関連の統計は政府、政策研究機関など多様な需要者層で活用できる。そこで、国内企業や大学・公共研究機関の知的財産活動及びインフラなどの情報を総合的に測定・分析するため 2006 年に知的財産活動実態調査がスタートした。

知的財産活動実態調査は次のような目的で行われている。第一、国内企業と大学・公共研究機関における知的財産の創出、権利化及び保護、活用状況を調査・分析し、信頼できる情報を提供する。第二、知的財産活動の主要項目に対する年度別比較を通じて国内知的財産活動のトレンドを分析する。第三、これを通じて企業及び大学・公共研究機関の合理的な意思決定を支援するとともに、知的財産政策の樹立に反映させる。

### 2. 調査沿革

2006 年にスタートした「企業知的財産活動調査」は活発に研究開発を行う国内企業(基準年度に 1 件以上の特許または実用新案を出願)を対象に施行された。企業を対象にした理由は、最近 15 年間(1990 年～2004 年)内国人の特許出願を企業(出願件数基準で 76.7%)が主導していることに対して(特許庁、2005)、知的財産部分において大学や公共研究機関に比べて企業を対象にした調査統計が相対的に少なかったためである。また、特許または実用新案の出願数を基準にした理由は特許出願件数が研究開発費の規模と密接に関係しているため、出願規模によって

調査対象企業を選定する方が企業の全般的な知的財産活動状況を理解する上で効果的であると判断したためである。

2007年には2006年度の調査結果を基に調査質問事項の一部を修正し、知的財産活動の段階別先行活動に対する質問事項を細分化することで、知的財産活動実態調査の統計的な安定性(stability)と妥当性(validity)を強化するための改善プロセスが行われた。また、知識の創出及び拡散をリードする公共研究機関(大学を含む)の重要性を考慮し、調査対象を従来の企業から大学・公共研究機関まで拡大した。<sup>2</sup>

2008年度には回答者の利便性と情報活用度を高めることができると判断される項目を中心に回答方法及び調査質問事項を一部修正、改編(2008年7月承認統計変更)した。従って、2007年度の知的財産活動調査結果と比較する時は調査回答方法と質問事項の変更による差異を把握した上で使用する必要がある。2009年度の調査では実態調査結果の活用性を高めるため、一部時宜性の低い質問事項を削除し、実態調査質問事項に対する企業と政策ニーズを調査・反映した(2009年7月承認統計変更)。

また、知的財産関連の類似調査の重複実施による企業、大学・公共研究機関の回答負担を減らし、よりクオリティの高い調査のため2011年度には貿易委員会が毎年実施している「知的財産権侵害実態調査」を統合することで、知的財産の創出、保護、活用及び侵害と関連する最も広範囲な調査としての枠組みを備えることができた。2012年には知的財産活動実態調査結果の活用性を最大化するため、再び調査項目に対する改善を図った。標本の信頼度を考慮し、調査項目に対する需要を検討して、その意見を反映することで最終調査項目を確定した。

---

<sup>2</sup> そこで統計の名称も「企業知的財産活動調査」から「知的財産活動調査(The Survey of Intellectual Property -Related Activities、承認番号第13802号)」に変更された。

2013 年には累積データを基に年度別変化の推移分析を強化し、専門家の検証過程を強化することで、知的財産活動の流れを診断・分析し、有意味な指標産出を通じて知的財産活動の状況が把握できるように取り組んだ。

2014 年度には企業類型を考慮して標本設計を精巧化し、アンケートを再構成することで調査の正確性を高めた。主要指標の場合は追加分析を通じて政策的な活用度が高められるように取り組んだ。

## 第2節 調査質問事項及び標本設計

### 1. 調査質問事項の設計

#### (1) 知的財産活動の定義

知的財産活動は「知的財産の創出と保護、活用に関連する全ての活動」を意味するものと定義づけられる。従って、知的財産(intellectual property)の範囲を如何に設定するかによって知的財産活動実態調査で測定しようとする対象と調査領域が変わってくる。広義としての「知的財産」は発明、考案、デザイン、商標、著作物、公演など人間の創造的活動によって創られた科学技術的、文学・芸術的な成果を意味する。<sup>3</sup>知識基盤経済で知的財産に対する関心が高まっている理由は、知的財産が生産性の向上及び経済成長をリードする中核要因となったためである。また、企業価値の源泉も有形資産から知的財産を含む無形資産へとスピーディーにシフトしつつある。

しかし、知的財産の範囲を広義の概念に拡大する場合、統計データの集計及び調査方法における困難が予想される。即ち、測定の対象である知的財産の概念が包括的であるほど回答者の主観が介入したり、生データ(raw data)の品質が低下する矛盾関係(trade-off)に直面する可能性が高い(チェ・ソンホなど、2006)。そこで、本調査では効果的に調査を行うため、知的財産の範囲を文学・芸術的な表現と関連する著作権を除く科学技術分野の産業財産権<sup>4</sup>に限定し、調査質問事項によってノウハウなど新知的財産権の一部を含めることにする。

知的財産の活動は大きく創出、権利化及び侵害対応に分けられる。その主な活動は[表 1.1]のとおりである。

---

<sup>3</sup> 世界知的所有権機関(WIPO)と日本知的財産基本法では知的財産を「発明、著作物、公演など人間の創造的な活動による科学技術的、文学・芸術的な成果が権利として保護を受けること」と規定している。

<sup>4</sup> 特許権、実用新案権、デザイン権、商標権

[表 1.1] 知的財産活動の分類

	目標	主要活動
創出	研究開発活動の生産性向上と価値のある知的財産の創出及び獲得	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先行特許調査</li> <li>・ 研究開発 (R&amp;D) 投資</li> <li>・ 知的財産の導入</li> </ul>
権利化及び保護	知的財産の価値を最大化し、それにかかる費用を最小化するための権利化及び保護戦略の実行	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予備評価</li> <li>・ 知的財産保護戦略の選択</li> <li>・ 産業財産権の国内外出願</li> </ul>
活用	保有している知的財産の効果的な活用を通じた十分な収益の創出及び費用節減	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保有知的財産の実査評価</li> <li>・ 技術取引システムの活用</li> <li>・ 事業化または売却・移転</li> </ul>
侵害及び紛争対応	権利化された知的財産権の経済的価値を保護するため、外部からの知的財産権侵害に対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 知的財産権侵害のモニタリング</li> <li>・ 知的財産権侵害の際、警告書の送付、司法措置などの対応</li> </ul>

(2) 主要調査質問事項

前述したように知的財産活動実態調査の調査質問事項は企業、大学・公共研究機関の知的財産活動と密接に連携している要素やシステムの活用状況、そしてその結果を測定する上で必要な核心内容を反映して設計しようとした。但し、出願人別国内産業財産権の出願件数などのように特許庁を中心に既に調査・公表されている項目は調査項目から除外している。<sup>5</sup>

<sup>5</sup> このような統計資料は知的財産統計年報(特許庁)、韓国の特許動向(特許情報院)などから確認できる。



[表 1.2] 知的財産活動実態調査の主要調査項目

分類	主要調査項目
一般事項 及び インフラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会社形態、輸出状況*</li> <li>・ 従業員数及び売上高*</li> <li>・ 研究開発人材及び研究開発費</li> <li>・ 知的財産担当組織及び人材、職務教育の状況</li> <li>・ 知的財産サービスの活用状況</li> </ul>
特許基盤の 知的財産活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先行特許(技術)調査など特許情報の活用               <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 先行特許(技術)調査の活用状況、必要性、担当人材など</li> </ul> </li> <li>・ 職務発明補償の状況               <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 職務発明補償規定の保有及び活用状況、補償金の水準及び補償費用、関連制度の効果など</li> </ul> </li> <li>・ 技術取引機関、技術マーケティング会社との協力               <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 技術取引機関への業務依頼及び協約締結、技術取引システムの活用度、特許技術事業化における問題点など</li> </ul> </li> </ul>
知的財産の 創出及び活用 活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外部からの知的財産導入(outsourcing)の方向と戦略               <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 外部から知的財産導入の方式及び導入経路による実績、知的財産導入に向けた投資計画など</li> </ul> </li> <li>・ 保有している知的財産に対する実査活動               <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 実査の実施状況、必要性、実施人材など</li> </ul> </li> <li>・ 知的財産の売却移転活動               <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 売却移転の実績、売薬移転時の問題点など</li> </ul> </li> <li>・ 産業財産権の活用状況               <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 産業財産権の活用状況及び未活用の主な理由など</li> </ul> </li> <li>・ 効果的な知的財産保護のために必要な政策支援</li> </ul>
知的財産 保護活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予備評価の実施活動               <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 予備評価の実施状況、必要性、担当人材など</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・知的財産保護戦略の活用度</li> <li>・知的財産の管理及び保護に関する認識度</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・産業財産権の国内外出願・登録実績及び今後の計画</li> <li>・出願・審査・維持の費用</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・効果的な知的財産保護のために必要な政策支援</li> </ul>
知的財産の侵害及び紛争対応活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・知的財産権の侵害及び被害規模</li> <li>・知的財産権侵害に対するフォローアップ</li> <li>・知的財産権紛争関連の問題点</li> <li>・知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策</li> </ul>

\* 企業に対してのみ調査

まず、調査項目は知的財産活動の基盤となるインフラ領域(知的財産人材、知的財産管理システムなど)と特許基盤の知的財産活動分野、知的財産の創出及び活用活動に関する事項、知的財産の保護及び権利化に関する事項、知的財産権の侵害及び紛争対応活動に関する事項に区分して構成した。また、各活動分野による状況、問題点、求められる政策需要などを調査することで、企業及び大学・公共研究機関で行われる知的財産活動の特性がより体系的に理解できるようにした。調査項目別の主な調査質問事項は[表 1.2]のとおりである。

## 2. 標本設計

### (1) 母集団及び標本規模

2010年までの「知的財産活動実態調査」と「知的財産権侵害実態調査」の母集団及び標本は[表 1.3]のように相異なる。「知的財産活動実態調査」の場合は知的財産活動を活発に進めている企業及び機関が調査対象であるため、最近2年間特許及び実用新案を出願した企業及び大学・公共(研)を母集団に入れてきた。また、「知的財産権侵害実態調査」は侵害対象の知的財産権を保有する企業を調査対象としているため最近5年間産業財産権を登録した企業を母集団に入れた。

[表 1.3]既存知的財産権侵害実態調査と母集団の比較

調査区分	母集団	標本
知的財産活動 実態調査 (特許庁)	・ 2 年間(2007～2008) 2 件以上の <b>特許及び実用新案</b> 出願企業、大学・公共(研)	・ <b>全数調査</b> ：10 件以上特許及び実用新案を出願した企業(2 年間) ・ <b>標本調査</b> ：出願 10 件未満の企業を対象に業種を分類して標本を抽出(20～35%)
知的財産権 侵害実態調査 (貿易委員会)	・ 直前 5 年間(2005～2009)1 件以上 <b>産業財産権(特許、実用新案、商標、デザイン)</b> を登録した企業	・ <b>全数調査</b> ：100 件以上産業財産権を登録した企業(5 年間) ・ <b>標本調査</b> ：産業財産権登録件数別に 9 つのグループに分け、登録件数加重が適用された分布によって比例割当

2011 年調査では[表 1.3]のように母集団が相異なる「知的財産活動実態調査」と「知的財産権侵害実態調査」が統合されたことで母集団変更の必要に迫られた。2011 年調査では現在活発な知的財産活動を行うと同時に、侵害対象の知的財産権を保有している企業及び大学・公共(研)を母集団に含める必要があった。そこで、2 年間(2008～2009)2 件以上の産業財産権を出願し、同時に 5 年間(2006～2010)1 件以上登録した企業及び大学・公共(研)を母集団に含めた。出願対象を既存の特許、実用新案から最近産業財産権としての価値が高まりつつあるデザインと商標までその範囲を拡大した。2014 年調査では 2011 年と同じ母集団を対象にした。

母集団に含まれる大学・公共研究機関は「技術移転及び事業化促進に関する法律」第 2 条に基づいて国公立試験研究機関、科学技術分野政府出捐研究機関、特定研究機関、専門生産技術研究所、非営利法人及び団体、国公立大学及び私立大学を意味し、公企業及び地方自治団体は除外した。

2014 年度調査における母集団の規模は企業が 20,569 社、大学・公共研究機関が 230 個である。母集団に含まれる企業、大学・公共研究機関のうち 20 件以上(年平均

10 件以上)の産業財産権を出願したり、100 件以上(年平均 20 件以上)を登録<sup>6</sup>した企業は 1,965 社である。

[表 1.4]年度別母集団の規模

	母集団の規模	企業	大学及び公共(研)
2007 年	10,202	10,050	152
2008 年	11,470	11,292	178
2009 年	11,987	11,792	195
2010 年	13,392	13,165	227
2011 年	17,440	17,220	220
2012 年	18,656	18,418	238
2013 年	20,795	20,566	229
<b>2014 年</b>	<b>20,799</b>	<b>20,569</b>	<b>230</b>

標本抽出のために産業財産権の出願規模と業種(企業)、機関類型(大学・公共研究機関)を基準に 2 次層化した後、最終標本機関を選定した。母集団に含まれる企業は 2007 年 12 月 28 日改正告示された第 9 次韓国標準産業分類表(KSIC)を基準に 13 業種に区分した。<sup>7</sup> 産業財産権の出願及び登録規模と業種(企業)、機関類型(大学・公共研究機関)に区分された母集団の分布は[表 1.5]、[表 1.6]のとおりである。

[表 1.5]企業母集団の分布

(単位：個、%)

	20 件以上出願(or)100 件以上登録	20 件未満出願 (and)100 件未満登録	合計	比重
農林水産及び鉱業、飲食	90	599	689	3.3

<sup>6</sup> 全数調査の対象は既存調査での基準を適用する。全数調査対象標本の分布は[表1.5]のとおりである。

<sup>7</sup> 業種分類と韓国標準産業分類表(KSIC)との連携表は付録 1 を参照

料及びタバコ製造業				
卸及び小売業	242	2,619	2,861	13.9
事業サービス業、通信業	187	1,837	2,024	9.8
金融及び保険業	37	85	122	0.6
建設業	80	1,330	1,410	6.9
その他サービス業	196	2,022	2,218	10.8
繊維製品、衣服、靴製造	98	580	678	3.3
紙及び印刷、出版業	20	179	199	1.0
化学産業	239	1,446	1,685	8.2
鉄鋼及び金属産業	56	595	651	3.2
電気電子産業	172	1,479	1,651	8.0
機械産業	483	5,314	5,797	28.2
その他製造業	65	519	584	2.8
合計	1,965	18,604	20,569	100.0
比重	9.6	90.4	100.0	

[表 1.6] 大学・公共研究機関の母集団の分布

(単位：個、%)

	20 件以上出願 (or) 100 件 以上登録	20 件未満出願 (and) 100 件未満登録	合計	比重
国公立大学	29	8	37	16.1
私立大学	80	67	147	63.9
政府出捐(研)	21	0	21	9.1
その他公共機関	13	12	25	10.9

合計	143	87	230	100.0
比重	62.2	37.8	100.0	-

各業種及び機関類型によって母集団の数が決まった後、業種(企業)内での出願規模別割当は基準年度に 20 件以上(年平均 10 件以上)の産業財産権を出願したり、100 件以上(年平均 20 件以上)登録した企業は全数を調査対象とした。5 年間登録件数別全数調査対象の比率は[表 1.7]のとおりである。

[表 1.7] 企業登録件数別の全数調査対象の比率

登録件数	全体企業数	全数調査対象企業数	全数調査の比率 (%)
10～19 件	3200	210	6.6
20～29 件	1085	344	31.7
30～39 件	486	235	48.4
40～49 件	270	170	63.0
50～59 件	172	142	82.6
60～69 件	126	103	81.7
70～79 件	86	74	86.0
80～89 件	69	67	97.1
90～99 件	41	36	87.8
100 件以上	471	471	100.0

また、基準年度に 20 件未満(年平均 10 件未満)の産業財産権を出願した企業などに対しては多段階層化系統抽出法を適用することで、基本的に業種を 1 次層にし、更に規模(出願及び登録件数)基準で 2 次層化した後、ランダムサンプリング法を施行した。業種(企業)によって区分された各集団に対する標本割当比率は平均 10%を適用した。業種(企業)別に割当てられた標本の分布は[表 1.8]のとおりである。

[表 1.8]企業標本の分布

	全数調査企業数	割当てられた 標本企業数	総標本企業数
農林水産及び鉱業、飲食 料及びタバコ製造業	90	60	150
卸及び小売業	242	262	504
事業サービス業、通信業	163	184	347
金融及び保険業	37	8	45
建設業	80	133	213
その他サービス業	220	202	422
繊維製品、衣服、靴製造	98	58	156
紙及び印刷、出版業	20	18	38
化学産業	239	145	384
鉄鋼及び金属産業	56	59	115
電気電子産業	172	148	320
機械産業	483	531	1,014
その他製造業	65	52	117
合計	1,965	1,860	3,825
比重	51.4	48.6	100.0

## (2)母集団推定

本報告書では 4,055 の企業及び大学・公共研究機関を標本調査して収集された結果を基に母数推定(parameter estimates)を行い、その結果を 2 章(企業)及び 3 章(大学・公共研究機関)で提示している。母集団推定のためには標本を抽出した業種及び機関類型と出願規模別に層化された 34 の集団(企業 26 社、大学・公共研究機関 8 つ)

に対して回収されたアンケート調査の回答を集計した後、これを母集団規模まで拡大して母集団値を推定している。その際、次のような方法で作られた加重値を活用している。

$$W_{ij} = \frac{N_{ij}}{n_{ij}}$$

ここで  $N_{ij}$  は層化された各集団に含まれる母集団の数であり、 $n_{ij}$  は層化された各集団別回答企業の数である。また、既存実態調査結果との連続的な比較のため、母集団を2010年以前と類似するよう構成(基準年度に特許、実用新案2件以上出願した企業、大学・公共研究機関)した時の推定値を別途括弧で表示している。

本報告書に収録されている統計表では調査結果を企業の類型<sup>8</sup>(大企業、中堅企業、一般中小企業、ベンチャー/Inno-biz 企業)、大学・公共(研)の類型(私立大学、国立大学、政府出捐研究機関、その他公共研究機関)に分けて提示している。これは中堅企業の役割が重要になっていることから、中堅企業の知的財産活動の状況を把握・分析することで、格別な国家知的財産戦略を樹立するとともに合理的な制度及び政策施行を支援するためである。また、出願規模による差異を示すため、産業財産権出願件数別<sup>9</sup>の数値を別途提示している。

---

<sup>8</sup> 大企業の場合は相互出資制限企業集団でグループの資産総額が5兆ウォンを超える企業であり、中堅企業は産業発展法第10条に基づいて中小企業を卒業した企業のうち相互出資制限企業集団に属さない企業として区分する。また、中小企業基本法第2条に基づき、中小企業は製造業基準300人未満の企業として区分する。

<sup>9</sup> 年10件未満、11～20件、21～60件、61件以上で区分



## 第3節 調査方法及び結果

### 1. 調査方法

本調査の調査対象期間は2013年1月1日から2013年12月31日までを基準とし、12月決算でない場合は質問事項別に回答の利便性を考慮して2013年(1月～12月)または直前会計年度のうち一つを選択して回答できるようにしている。調査質問事項の中で先行特許活動、産業財産権の活用状況(収入と支出を除く)、知的財産担当人材の状況などの質問事項は回答時点を基準にしている。

調査方法は3段階ハイブリッド方法(Hybrid Method)を活用している。1段階の定性調査では企業、大学・公共研究機関の知的財産担当者と構成された諮問グループを構成し、フォーカスグループインタビュー(Focus Group Interview)を実施している。これを通じて調査票の回答利便性及び活用性を検討した。

[表 1.9]2段階アンケート調査のプロセス及び方法

調査プロセス	調査方法
調査準備	企業情報自動確認システムを通じて調査対象企業の連絡先の有効性を一括点検→調査効率性の改善及び調査期間の短縮
アンケート調査	標本選定企業を対象にメール、FAX、電話調査を実施 回収率を高めるための調査対応をマニュアル化(調査拒否、理解不足など)
資料 エディティング	1次資料を取り集める 項目間、回答内容間でのロジックの合理性を確認
補完調査及び 資料入力	異常回答値に対して専門調査員が補完調査 エディティング及び補完調査が全て完了した資料に限りデータ入力

2段階ではアンケート調査を行った。アンケート調査期間は2014年7月16日から10月14日まで約3ヶ月間である。調査は郵便アンケート調査(Mail Survey)を基本調

査方法として使用し、韓国知識財産研究院のホームページを通じてアンケート用紙を直接ダウンロードして作成できるようにした。調査のためにまず対象となる企業及び大学・公共研究機関との事前接触を通じて主たる回答者を決め、郵便でアンケート用紙を発送する方法で進めた。本調査の主要回答者は各企業の特許関連専担部署及び関連部署、大学の産学協力団、技術移転センター(TLO)などの関連業務担当者である。調査拒否の場合、杜撰な回答である場合、回答が無い場合は以下のマニュアルに従って対応した。

[表 1.10] 調査拒否及び杜撰な回答である時の対応策

	事例	対応策
調査 拒否	内容が 理解できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 知的財産分野の産業分析専門家で構成された調査支援チームが調査の目的、調査のメリット、事業内容及び回答方法に対して再び説明</li> <li>・ 調査支援チームの説明の後に同じ理由で調査を拒否する場合、意図的な調査拒否と看做して調査対象企業から外す</li> </ul>
	回答できない 内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 企業が一定規模以上である場合、調査分野別に回答可能な部署が違いため、担当者の適正性を再確認</li> <li>・ 調査内容が業種及び規模に合わないため回答できない場合は業種を再確認して適した調査用紙を発送、小規模な企業である場合は該当する質問事項のみ回答できるように案内</li> </ul>
	調査対象に 適した企業で はない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査支援チームが取扱い製品やサービスを確認し、適合性を判断</li> <li>・ 適合した企業として判定された場合、その事由を企業に伝えて調査参加を再要請する</li> </ul>
	調査に応じる 時間がない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査対象企業が以前調査回答企業であったり、業種別有効標本を確保するための必須調査対象である場合、前年度の調査回答企業である場合、既存回答資料の変動事項のみ修正を要請</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記の調査条件に対しても拒否する場合、調査対象企業から外す</li> </ul>
	特別な事由のない調査拒否	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査の目的及び調査結果の活用方向などを再び説明</li> <li>・説明の後も拒否する場合、調査対象企業から外す</li> </ul>
杜撰な回答	回答値が会社規模(売上状況及び人材状況)に比べて過大/過小値である場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実査担当研究員がエディティング過程で選別する</li> <li>・企業情報 DB 内の該当企業情報を詳細検討し、回答値の有効性を判断</li> <li>・異常値として判断された場合、関連質問事項のみ電話で再調査を実施</li> </ul>
	類似した質問事項に相反する内容の回答である場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実査担当研究員がエディティング過程で選別</li> <li>・質問事項間の回答有意性を確認した後、異常値として判断された場合、該当質問事項のみ電話で再調査を実施</li> <li>・回答が全体的に連結性がなく適当に作成されたものと判断された場合、該当回答用紙の廃棄及び再調査または代替企業を調査</li> </ul>

[表 1. 11]回答が無い場合の対応策及び欠測値の補正方法

事例	対応策
企業秘密に該当すると判断して回答しない質問事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査機関の対外認知度及び信頼性に対して説明した後、再び協力を求めると同時に調査結果は全体統計としてのみ活用されることを強調</li> <li>・必要な場合は訪問を通じて信頼性を確認した後、補強調査</li> <li>・保有している財務資料 DB を活用して一部補完</li> </ul>
作成途中に回答を中断した場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社の基本(概要)情報のみ回答した場合と調査の 50%以上回答しなかった場合、該当アンケート用紙は廃棄⇒代替企業を調査</li> <li>・アンケートに対する回答が 50%未満であるものの必須調査項目には答えた場合、電話で再調査を実施</li> </ul>

欠測値の補正方法	・単一確率代入法(Single Stochastic Imputation) <sup>10</sup> を活用
----------	--

最後の3段階では活発な知的財産先行活動を行っている企業、知的財産導入及び売却企業、知的財産権侵害事例企業を対象に担当研究員が調査対象を直接訪問してインタビューを行っている。これを通じて具体的な知的財産先行活動及び売却/移転方法、具体的な知的財産権の被害内容及び事件経過などを把握した。

## 2. 調査結果

調査対象である4,055の機関のうち、不渡りや廃業、欠番などによって発生した標本損失を除外した有効標本規模<sup>11</sup>を基準にした回答率<sup>12</sup>は46.7%となっており、前年度回答率の43.6%より3.1%p増となっている。企業は1,200社が回答して43.4%、大学・公共研究機関は187機関が回答して90.3%の回答率となっている。企業業種別有効標本の規模及び回答率は[表 1.12]と[表 1.13]のとおりである。

[表 1.12] 有効標本の規模及び回答率

(単位：個、%)

区分	抽出した標本	欠番/その他	該当無し	不渡/廃業	重複	有効標本	事前拒絶	回答企業	回答率
企業	3,825	220	0	20	6	3,579	816	1,200	43.4
大学・公共(研)	230	0	0	1	0	229	22	187	90.3

<sup>10</sup> 平均代入法で観測された資料を基に推定された統計量で欠測値を代入する時、ある適切な確率値を与えた後代入する方法。この方法は推定量の標準誤差が過小推定される問題が補完できる。

<sup>11</sup> 有効標本規模 = {[抽出した標本規模] - ([欠番及びその他] + [該当無し] + [不渡/廃業] + [重複])}

<sup>12</sup> 回答率 = {[実際の回答規模] ÷ ([有効標本規模] - [事前拒絶])} × 100

[表 1.13]業種別有効標本の規模及び回答率

(単位：個、%)

業種名	抽出した標本	欠番/ その他	該当 無し	不渡 /廃業	重複	有効 標本	事前 拒絶	回答 企業	回答率
農林水産及び鉱業、飲 食料及びタバコ製造業	150	9	0	1	1	139	26	44	38.9
卸及び小売業	504	45	0	5	0	454	131	108	33.4
事業サービス業、通信業	347	29	0	4	0	314	86	75	32.9
金融及び保険業	45	0	0	1	0	44	19	15	60.0
建設業	213	8	0	0	1	204	42	65	40.1
その他サービス業	422	34	0	3	1	384	96	71	24.7
繊維製品、衣服、靴製造	156	5	0	1	0	150	34	48	41.4
紙及び印刷、出版業	38	2	0	0	0	36	11	15	60.0
化学産業	384	12	0	1	1	370	78	169	57.9
鉄鋼及び金属産業	115	2	0	0	0	113	28	60	70.6
電気電子産業	320	24	0	3	0	293	69	102	45.5
機械産業	1,014	43	0	1	1	969	177	401	50.6
その他製造業	117	7	0	0	1	109	19	27	30.0

また、業種別、機関類型別回答機関の分布は以下の[表 1.14]、[表 1.15]のとおりである。

[表 1.14]業種別、企業類型別回答企業の分布

区分		全数層 (企業数)	標本数 (企業数)	合計 (企業数)
業種	農林水産及び鉱業、飲食料及 びタバコ製造業	23	21	44

	卸及び小売業	49	59	108
	事業サービス業、通信業	32	43	75
	金融及び保険業	10	5	15
	建設業	23	42	65
	その他サービス業	36	35	71
	繊維製品、衣服、靴製造	26	22	48
	紙及び印刷、出版業	8	7	15
	化学産業	82	87	169
	鉄鋼及び金属産業	18	42	60
	電気電子産業	51	51	102
	機械産業	161	240	401
	その他製造業	13	14	27
企業 類型	大企業	101	30	131
	中堅企業	119	45	164
	一般中小企業	209	336	545
	ベンチャー企業/INNO-BIZ 企業	103	257	360
	合計	532	668	1,200

[表 1.15] 大学・公共(研)類型別回答機関の分布

区分	全数 (機関数)	標本 (機関数)	合計 (機関数)
国公立大学	26	6	32
私立大学	68	51	119
政府出捐(研)	18	-	18
その他公共研究機関	14	4	18
合計	126	61	187

## 第2章 企業の知的財産活動

第1節 知的財産活動のインフラ

第2節 特許基盤の知的財産活動

第3節 知的財産の創出及び活用

第4節 知的財産の保護

第5節 知的財産の侵害及び紛争

## 第2章 企業の知的財産活動

本章では標本調査の結果を基に母集団全体を推定した結果を提示している。そのために本調査では母集団を業種及び出願規模によって層化した 26 の企業集団に区分し、各集団別に回収されたアンケートの回答を集計した後、これを母集団規模に拡大して母集団値を推定している。企業知的財産活動の基盤となるインフラ領域、特許基盤の知的財産活動、知的財産の創出及び活用活動、知的財産保護活動、知的財産の侵害及び紛争対応活動の 5 つの活動領域を中心に主な結果を提示した。

### 第1節 知的財産活動のインフラ

#### 1. 知的財産担当組織及び人材

母集団に属している企業の 69.3% (76.5%) は知的財産の管理を担当する組織を保有していることがわかった([図 2.1])。担当組織の形態別から見ると、独立した専門担当部署を保有している比率が 4.7% (5.3%) であり、兼任組織<sup>13</sup>の保有比率が 64.6% (71.2%) である。

---

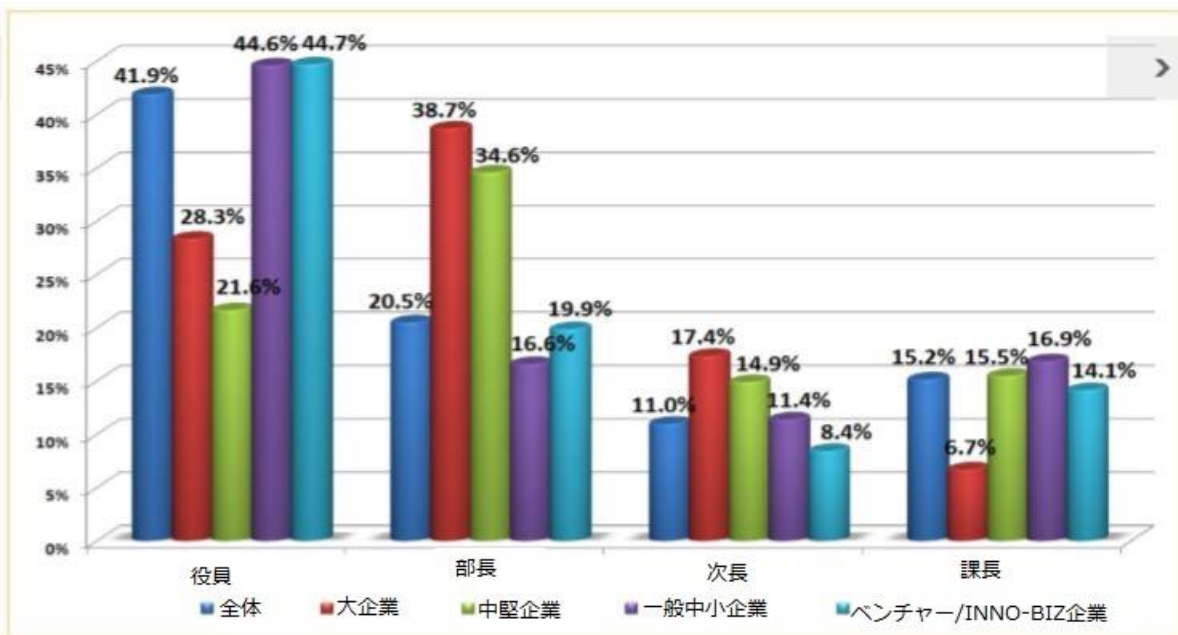
<sup>13</sup> 法務組織や研究開発組織、その他組織内に知的財産担当組織が存在





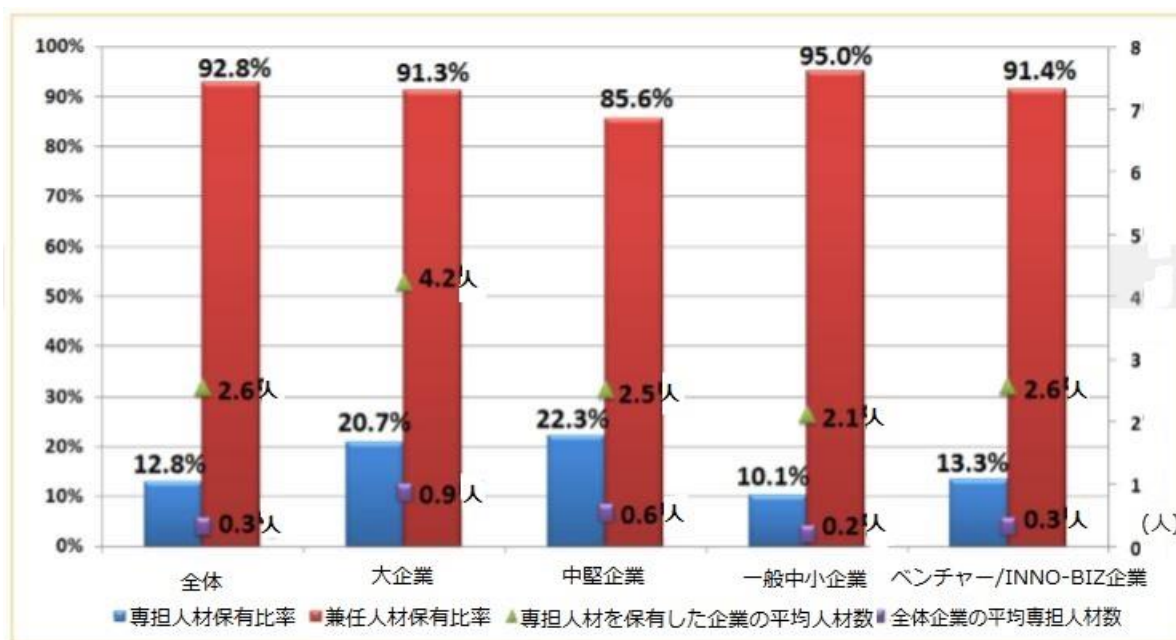
[図 2.1] 知的財産担当組織の保有状況

企業類型別では、大企業の 85.6% (85.4%)、中堅企業の 87.4% (94.7%)、中小企業の 65.3% (77.2%)、ベンチャー企業の 68.3% (70.7%) が知的財産担当組織を保有していることがわかった。特に、大企業と中堅企業の場合は知的財産担当組織が独立専門担当組織である比率が其々 9.7% (13.6%)、9.7% (10.5%) であり、他の企業類型に比べて相対的に高いことが分かる。



[図 2.2] 知的財産担当組織総括者の地位

知的財産担当組織総括者の地位と関連する分布は[図 2.2]のとおりである。知的財産担当組織総括者の地位が役員である比率は 41.9% (44.0%)と最も高く、部長 20.5% (23.3%)、課長 15.2% (12.0%)、次長 11.0% (10.7%)の順となっている。特に、中堅企業の場合は知的財産担当組織総括者の地位が役員である場合が全体の 21.6% (24.1%)と他類型の企業より低いことが分かる。出願件数別で見ると、知的財産担当組織総括者の地位が役員である比率は出願件数が多い多出願企業であるほど低くなる傾向(年平均 10 件未満出願企業の 43.8% (45.8%)、年平均 61 件以上出願企業の 21.1% (19.5%))となっている。小規模企業の場合は知的財産担当業務を役員レベル以上の職位で意思決定し、処理する場合がより多く、多出願企業であるほど知的財産を専門的に担当する総括人材の職位が明確であるものと解釈できる。



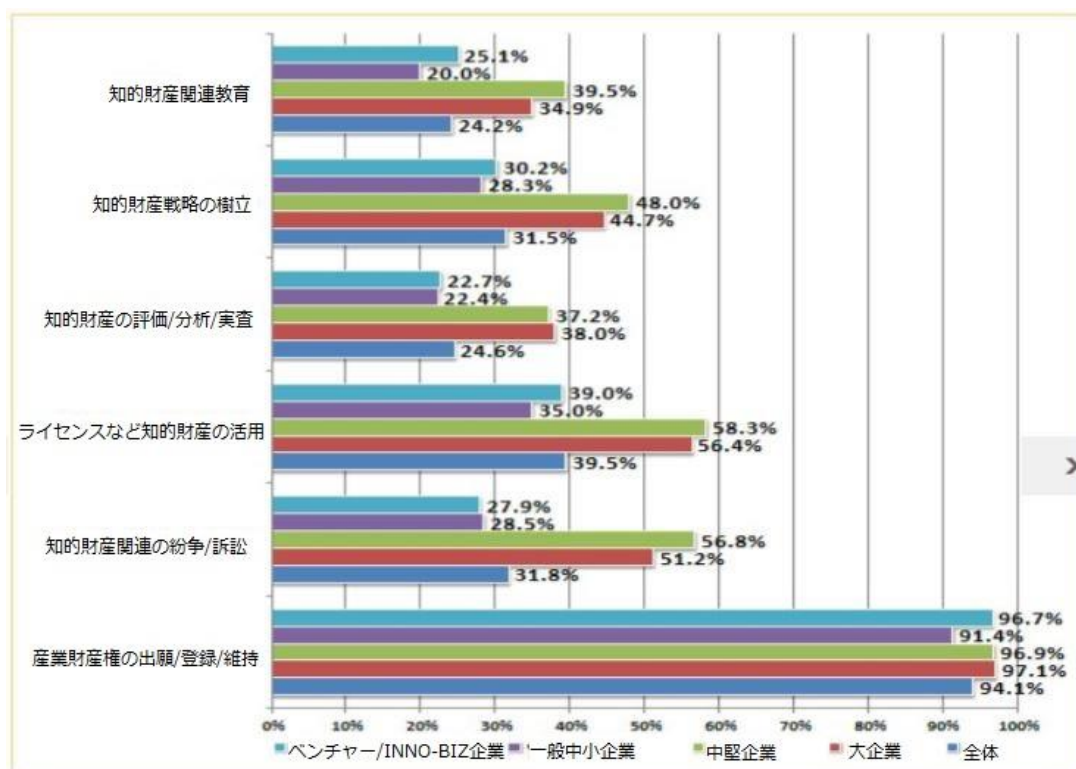
[図 2.3] 知的財産担当人材の保有状況

専ら知的財産関連業務だけを担当する専門人材<sup>14</sup>を保有している比率は全体の 12.8% (15.0%)、その他業務を並行する兼任人材を保有している比率は全体の 92.8%

<sup>14</sup> 知的財産担当人材は企業内で特許ポートフォリオ分析などの知的財産戦略企画、国内外産業財産権の出願及び登録・維持管理、知的財産権動向調査、特許侵害関連の対応及び訴訟業務、知的財産権の販売またはライセンス交渉及び技術料管理などの業務を担当する人材を意味し、この中で知的財産専門担当人材はこのような知的財産関連業務だけを専門的に行う人材を意味する。

(92.1%)となっている([図 2.3])。企業類型別では、大企業の 20.7% (26.3%)、中堅企業の 22.3% (25.9%)、中小企業の 10.1% (12.5%)、ベンチャー企業の 13.3% (13.5%)が 1 人以上の知的財産専担人材を保有していることが分かる。

全体企業の平均専担人材数は 0.3 人(0.4 人)であり、専担人材を保有している企業平均は 2.6 人(2.7 人)となっている。出願件数別で見ると、年平均 61 件以上を出願する企業の専門担当人材は平均 6.1 人(6.4 人)と平均専担人材数が多い。<sup>15</sup>兼任人材の場合も年平均 61 件以上出願する多出願企業が平均 3.0 人(2.6 人)と平均兼任人材が多い。<sup>16</sup>知的財産が多い企業の場合、専門性のある専担人材を多く保有するとともに兼任人材を多く採用していることが確認できる。知的財産専門人材は知的財産に対する専門性を基に知的財産権の確保及びリスク管理などを通じて企業の知的財産能力の強化に重要な役割を果たしていると思われる。



[図 2.4] 知的財産関連業務を行っている企業の割合

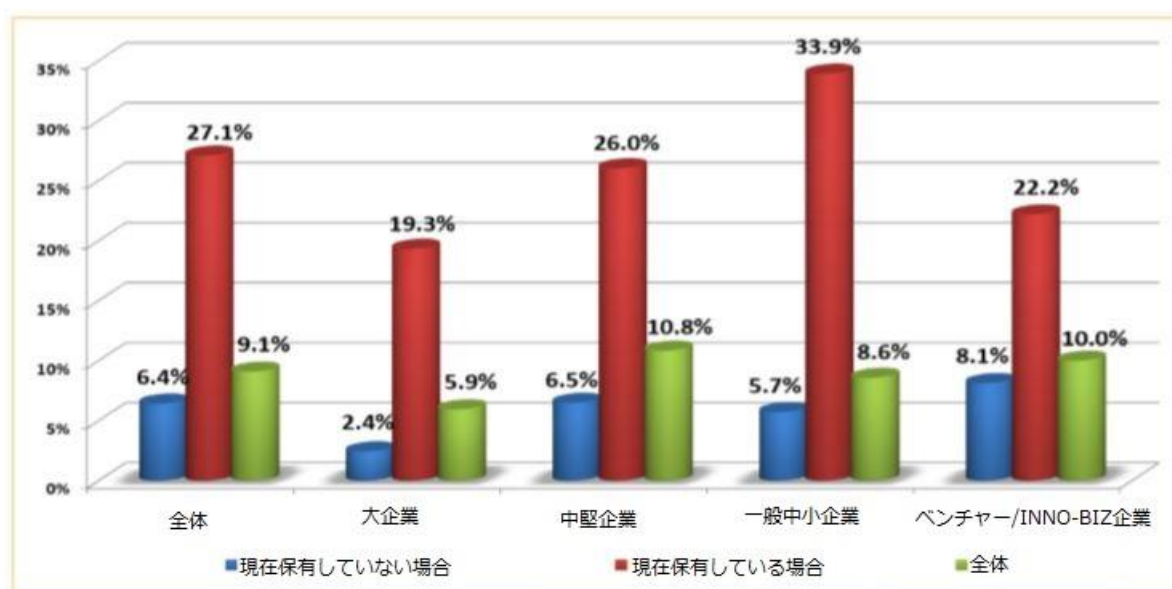
注. 知的財産担当人材を保有している場合である。

<sup>15</sup> 10件未満出願企業2.4人(2.5人)、61件以上出願企業6.1人(6.4人)

<sup>16</sup> 10件未満出願企業1.5人(1.6人)、61件以上出願企業3.0人(2.6人)

知的財産担当人材を保有している場合、担当業務の内容は[図 2.4]のとおりである。知的財産担当人材が知的財産関連の紛争/訴訟、知的財産の活用、関連戦略の樹立などの業務を行っている企業の比率は産業財産権の出願/登録/維持などの業務を行っている比率に比べて極めて低いことが分かる。特に、大企業や中堅企業に比べて一般中小企業及びベンチャー企業の場合は知的財産業務の内容が紛争/訴訟、ライセンスなどの専門的な業務よりは多少普遍的な出願/登録/維持業務を行う比率が相対的に高いことが分かる。

全体企業の 9.1% (10.0%) は今後知的財産担当人材を採用する計画があると回答している ([図 2.5])。特に、現在知的財産担当人材を保有している企業の 27.1% (28.5%) が新規及び追加採用計画があると答え、現在保有していない企業の 6.4% (6.8%) が新規及び追加採用計画があると回答している。既に知的財産担当人材を保有している企業の場合は知的財産の管理により集中しており、延いては新規及び追加の採用計画を持っている。相対的に知的財産担当人材を保有していない企業を対象に、知的財産の重要性に対する認識を高めるための取り組みが必要であると見られる。



[図 2.5] 知的財産専門担当人材の採用予定比率

企業類型別で見ると、中堅企業の 10.8% (11.2%) が新規及び追加採用計画があると答え、ベンチャー企業の 10.0% (9.2%) とともに高い数値を示している。特に、担当人材を保有していない企業を対象にした結果もまたベンチャー企業が 8.1% (7.0%) で他の企業類型に比べて高いことが分かった。これはベンチャー企業の場合、知的財産の管理に対する認識が最近になって高くなっていることを示唆している。出願件数別で見ると、新規及び追加採用予定の比率は出願件数が 61 件以上の多出願企業が 29.1% (31.9%) で最も高いことが分かった。<sup>17</sup>

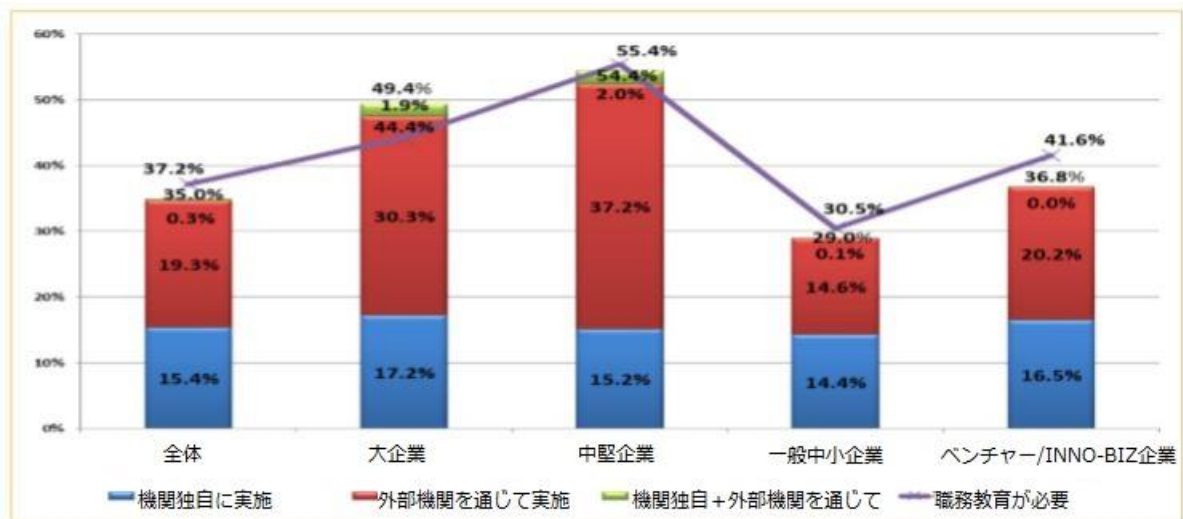
## 2. 知的財産担当人材に対する職務教育及び人件費・教育費

全体の 35.0% (38.4%) に該当する企業は知的財産担当人材に対する職務教育を実施していることがわかる ([図 2.6])。これは全体の 65.0% (61.6%) に該当する企業が知的財産担当人材向けの職務教育を如何なる形でも全く実施していないことを意味する。職務教育の形態別で見ると、独自に実施している場合が 15.4% (15.3%)、外部機関を通じて実施する場合は 19.3% (22.7%) となっている。

知的財産担当人材に対する職務教育の必要性は全体の 37.2% (40.6%) が必要またはとても必要であると認識していることがわかった。この比率は中堅企業が最も高い 55.4% (62.7%) で、一般中小企業は最も低い 30.5% (35.7%) となっている。特に、一般中小企業は現在職務教育を実施している企業の比率が 29.0% (31.9%) で、職務教育が必要であると感じる企業の比率に比べて低い水準である。このような相対的な差異は、一般中小企業の場合、職務教育の必要性は認識しているものの、時間や費用などあらゆる状況によって限界があるということを示し、これと関連する支援が求められる。

---

<sup>17</sup> 年平均10件未満出願企業8.4% (9.1%)、年平均61件以上出願企業29.1% (31.9%)



[図 2.6]知的財産権担当人材に対する職務教育の状況及び必要性

職務教育の内容に関しては全体の其々50.5% (51.4%)、41.4% (45.6%)が特許制度と特許情報検索に関する職務教育が必要であると回答している([表 2.1])。その他に特許ライセンス(技術事業化)と特許紛争及び訴訟に対する職務教育が必要であると回答した企業は其々38.7% (42.5%)と 35.5% (36.4%)となっている。特に、特許ライセンス及び技術事業化関連の職務教育が必要であると答えた比率はベンチャー企業が 44.3% (42.2%)と一般中小企業より高いことが分かる。相対的に技術を基盤にしているベンチャー企業の場合は保有技術の事業化が重要であるが、一方これを実行することに難航しているものと判断できる。

[表 2.1]職務教育の実施を希望する場合、扱うべき内容

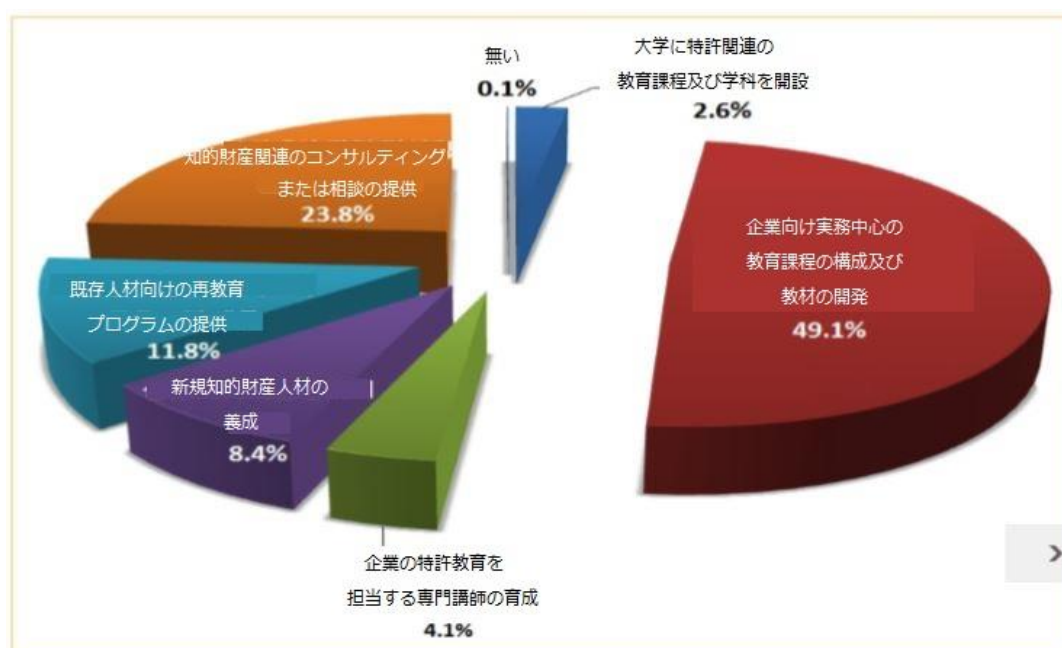
	全体	大企業	中堅企業	一般中小企業	ベンチャー・INNO-BIZ
特許制度	50.5%	47.3%	43.8%	48.4%	55.5%
特許明細書の作成法	24.3%	12.0%	24.9%	23.2%	27.8%
特許情報の検索	41.4%	34.3%	42.6%	38.0%	47.3%
特許紛争(訴訟)	35.5%	48.8%	47.6%	36.6%	29.0%
特許情報の分析方法(特許)	33.8%	29.3%	49.7%	30.4%	36.0%



マップ)					
特許ライセンス(技術 事業化)	38.7%	45.8%	45.1%	33.0%	44.3%
海外特許出願及び訴訟	24.6%	31.1%	23.0%	21.7%	28.1%
営業秘密の保護	22.8%	31.6%	23.2%	21.0%	23.7%
知的財産権の管理	0.4%	1.2%	1.3%	0.5%	0.0%

注. 複数回答

最後に、知的財産人材の能力強化のために必要な政府政策として、全体の 49.1% (48.2%) が実務中心の教育課程の構成及び教材の開発を挙げている ([図 2.7])。また、知的財産関連のコンサルティングまたは相談の提供と既存人材向けの再教育プログラムの提供が最も必要であると回答した比率も其々 23.8% (23.5%) と 11.8% (12.6%) となっている。知的財産能力を高めるために必要な政府政策に対する選好度は企業類型別に大きな差は見られない。但し、大企業の場合企業の特許教育を担当する専門講師の育成を挙げた比率が全体の 8.8% (10.1%) で、一般中小企業 4.9% (4.5%)、ベンチャー企業 2.1% (2.6%) より高い。



[図 2.7] 知的財産人材の能力を高めるために必要な政府政策

知的財産担当者の人件費及び教育費は[表 2.2]のとおりである。2013 年の 1 年間企業が支出した知的財産担当者の人件費と教育費は其々 2,647 万ウォン(3,069 万ウォン)と 83 万ウォン(108 万ウォン)<sup>18</sup>となっている。企業類型別では大企業、中堅企業、中小企業、ベンチャー企業が支出した平均人件費及び教育費の合計は其々 5,126 万ウォン(6,015 万ウォン)、4,008 万ウォン(4,700 万ウォン)、2,154 万ウォン(2,503 万ウォン)、2,915 万ウォン(3,176 万ウォン)となっている。

[表 2.2] 知的財産担当者の人件費及び教育費の状況

	人件費	教育費	合計
全体	2,647 万ウォン	83 万ウォン	2,731 万ウォン
大企業	5,032 万ウォン	93 万ウォン	5,126 万ウォン
中堅企業	3,855 万ウォン	153 万ウォン	4,008 万ウォン
一般中小企業	2,095 万ウォン	50 万ウォン	2,145 万ウォン
ベンチャー/INNO-BIZ 企業	2,800 万ウォン	115 万ウォン	2,915 万ウォン

### 3. 知的財産サービスの活用状況

2013 年の 1 年間外部の知的財産サービス<sup>19</sup>を利用した企業は全体の 43.3% (47.9%) となっている ([表 2.3])。企業類型別では大企業の 61.8% (72.8%)、中堅企業の 59.8% (65.4%) が知的財産サービスを利用したと回答し、ベンチャー企業 45.1% (44.9%)、一般中小企業 37.3% (43.7%) より多少高い比率であることが分かった。

<sup>18</sup> 企業が保有している知的財産担当者全員に対する総人件費及び教育費を意味する。

<sup>19</sup> 知的財産サービスとは知的財産の創出、管理、活用、保護、取引などを支援する専門サービスで、情報調査及び分析、技術移転及び取引、IP翻訳、コンサルティングなどの事業を意味する。



[表 2.3] 知的財産サービスの利用状況

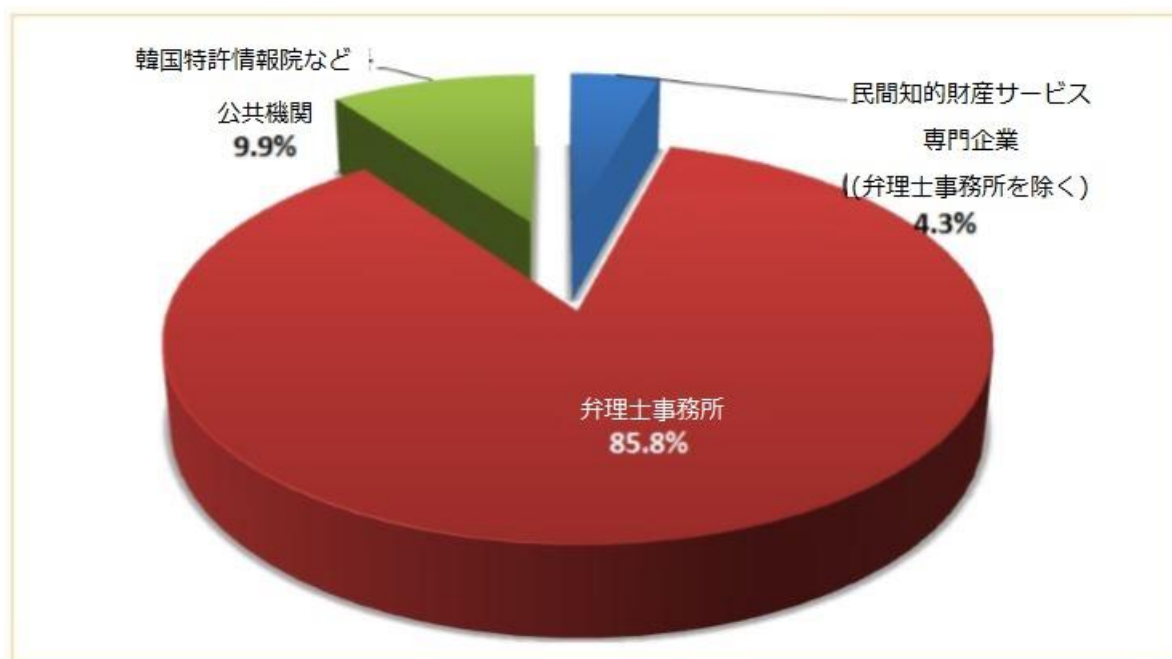
(単位：万ウォン)

区分	利用している	IP 情報調査/分析	技術移転/取引	IP 翻訳	IP コンサルティング	IP インフラ	その他	合計	
全体	43.3%	379	18	96	87	183	1,351	2,114	
企業 類型 別	大企業	61.8%	1,611	11	320	182	280	5,042	7,446
	中堅企業	59.8%	790	11	230	146	196	1,283	2,656
	一般中小企業	37.3%	242	30	65	49	217	714	1,317
	ベンチャー/INN00-BIZ 企業	45.1%	138	7	42	93	115	1,300	1,695
出願 件数 別	年平均 10 件未満	40.6%	144	12	68	69	113	823	1,229
	年平均 10～20 件	54.8%	484	36	31	113	133	1,974	2,771
	年平均 21～60 件	66.6%	1,696	66	133	126	179	2,404	4,604
	年平均 61 件以上	78.4%	4,776	7	1,286	497	2,855	1 億 4,947	2 億 4,368

知的財産サービスを利用した企業の 2013 年平均支出額はその他の場合以外に IP 情報調査/分析が 379 万ウォン(466 万ウォン)、IP インフラが 183 万ウォン(203 万ウォン)と相対的に高い比重を占めている。知的財産サービスに対する平均支出額は企業類型別に見ると、大企業と中堅企業、一般中小企業の場合は IP 情報調査/分析関連支出額が其々1,611 万ウォン(1,828 万ウォン)、790 万ウォン(923 万ウォン)、242 万ウォン(324 万ウォン)と相対的に高く、ベンチャー/INN00-BIZ 企業の場合は IP 情報調査/分析及び IP インフラ関連の支出が其々138 万ウォン(152 万ウォン)、115 万ウォン(129 万ウォン)である。ベンチャー企業の場合、技術移転/取引関連支出が 7 万ウォン

(9 万ウォン)で相対的に低いことで分かる。これは必要な職務教育の内容として特許ライセンス及び技術事業化を挙げたベンチャー企業の比率が比較的が高かった前の結果と関連付けられる。即ち、特許ライセンス業務を行う上で専門性の限界を感じており、これに対する人材の教育及び支援が求められていることが分かる。

知的財産サービスを提供する機関類型別利用比重は弁理士事務所が 85.8% (84.5%) と最も大きな比重を占めている ([図 2.8])。企業類型別では大企業 88.9% (87.4%)、中堅企業が 80.3% (80.8%)、一般中小企業 85.0% (82.1%)、ベンチャー企業 87.6% (87.2%) が弁理士事務所を利用していると回答している。特許情報院など公共機関は 9.9% (11.0%)、民間知的財産サービス専門企業は 4.3% (4.5%) となっている。特許情報院など公共機関の利用比重は中堅企業の場合 11.7% (11.9%) と他企業類型より相対的に高いことがわかった。



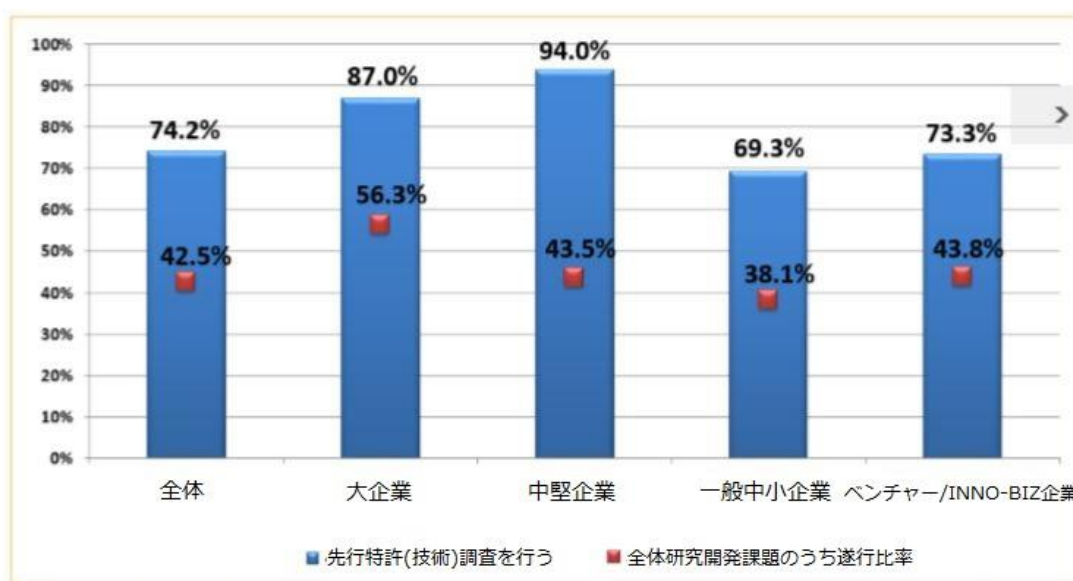
[図 2.8] 知的財産サービス提供機関別の利用比重

## 第2節 特許基盤の知的財産活動<sup>20</sup>

### 1. 先行特許(技術)調査など特許情報の活用

研究開発の企画段階で先行特許(技術)調査<sup>21</sup>など特許情報を調査する企業の比率は74.2%となっている([図 2.9])。この企業らは全体研究開発課題の42.5%に対して先行特許(技術)調査を行っていることがわかった。

企業類型別では大企業 87.0%、中堅企業 94.0%、一般中小企業 69.3%、ベンチャー企業 73.3%が先行特許(技術)調査を行っていると答えている。即ち、中堅企業が先行特許(技術)調査活動を最も活発に展開しており、全体研究開発課題のうち先行特許(技術)調査を行っている比率は大企業が56.3%で最も高く、一般中小企業が38.1%で多少低い結果となった。

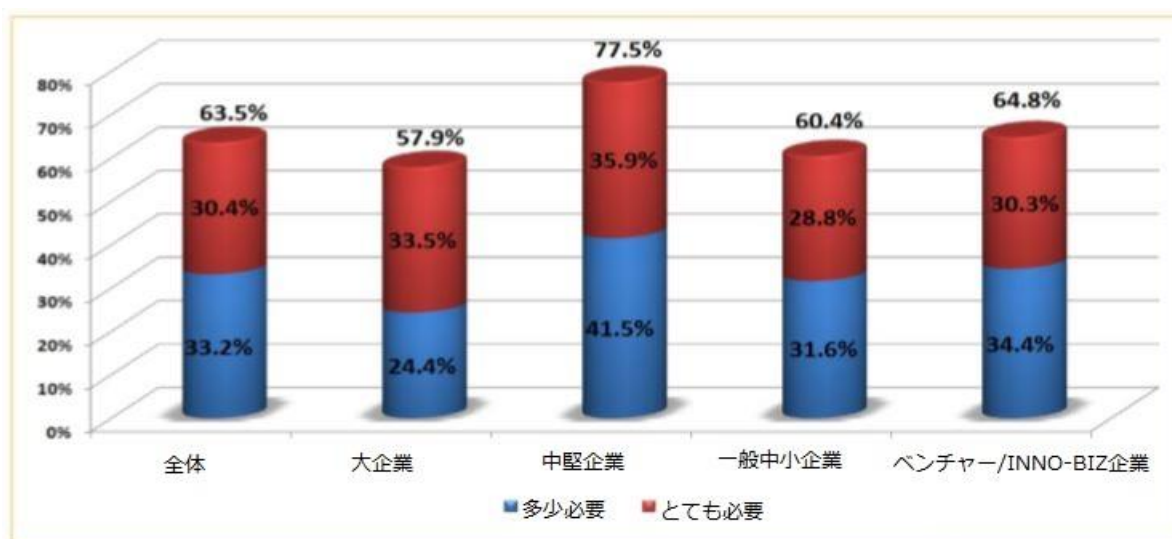


[図 2.9] 先行特許(技術)調査の実施状況

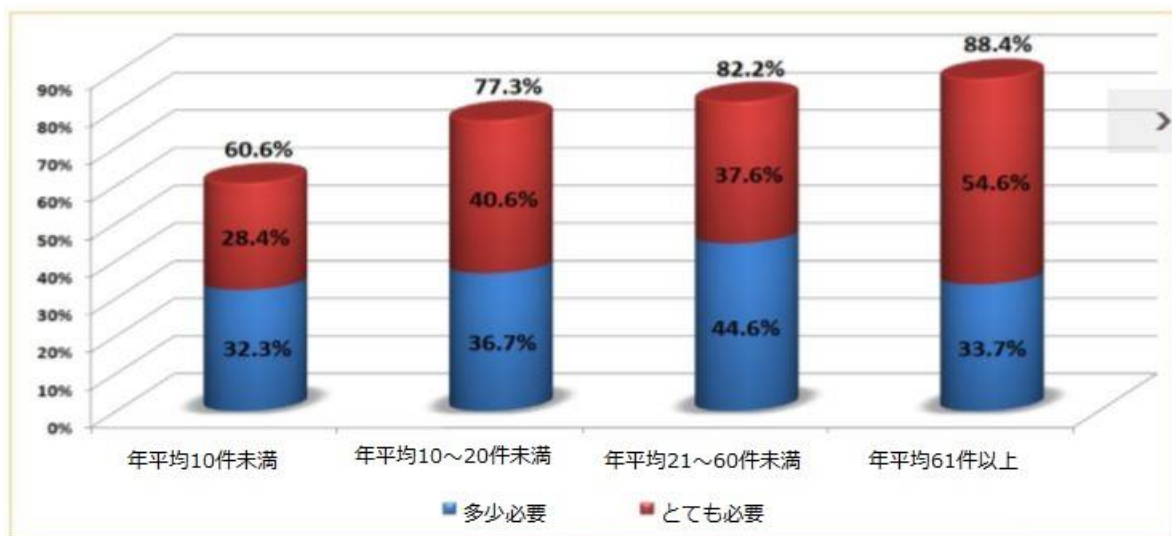
<sup>20</sup> 第2節 特許基盤の知的財産活動の場合、特許中心の活動に関する調査項目をグループ化して調査したもので、特許、実用新案基準中心の2010年母集団を基準に算出した結果値を表記した。

<sup>21</sup> 先行特許(技術)調査とは、新技術の開発などのための研究開発(R&D)活動に先立って開発しようとする技術に対する先行技術または該当技術と同一もしくは類似した特許が存在しているかどうかなどを調査するものである。

知的財産担当者が認識している先行特許(技術)調査の必要性に対しては全体の63.5%が必要またはとても必要であると回答している([図 2.10])。逆にいえば、全体の約36.5%が先行特許(技術)調査の必要性を全く認識していないものと解釈できる。企業類型別では中堅企業が先行特許(技術)調査の必要性に対して最も大きく認識していることが分かった。出願件数別に見ると([図 2.11])、多出願企業であるほど<sup>22</sup>先行特許(技術)調査がとても必要であると回答した比率が増加した。



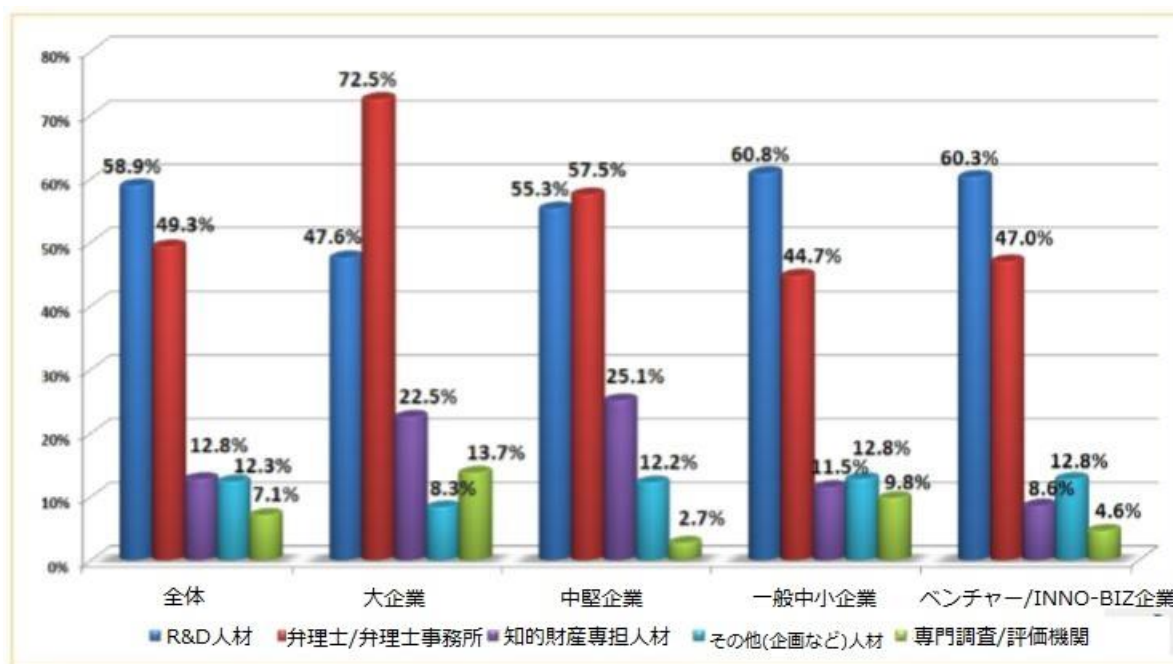
[図 2.10] 先行特許(技術)調査の必要性



[図 2.11] 出願件数別の先行特許(技術)調査の必要性

<sup>22</sup> 10件未満出願企業の場合60.6%、10-20件の場合77.3%、21-60件の場合82.2%、61件以上多出願企業の場合88.4%

先行特許(技術)調査を行っている場合の 58.9%が該当業務を R&D 人材を通じて行っていると答え、最も高かった([図 2.12])。また、弁理士及び弁理士事務所に依頼して行っている場合は 49.3%で 2 番目に高かった。



[図 2.12] 先行特許(技術)調査を行う場合の遂行人材

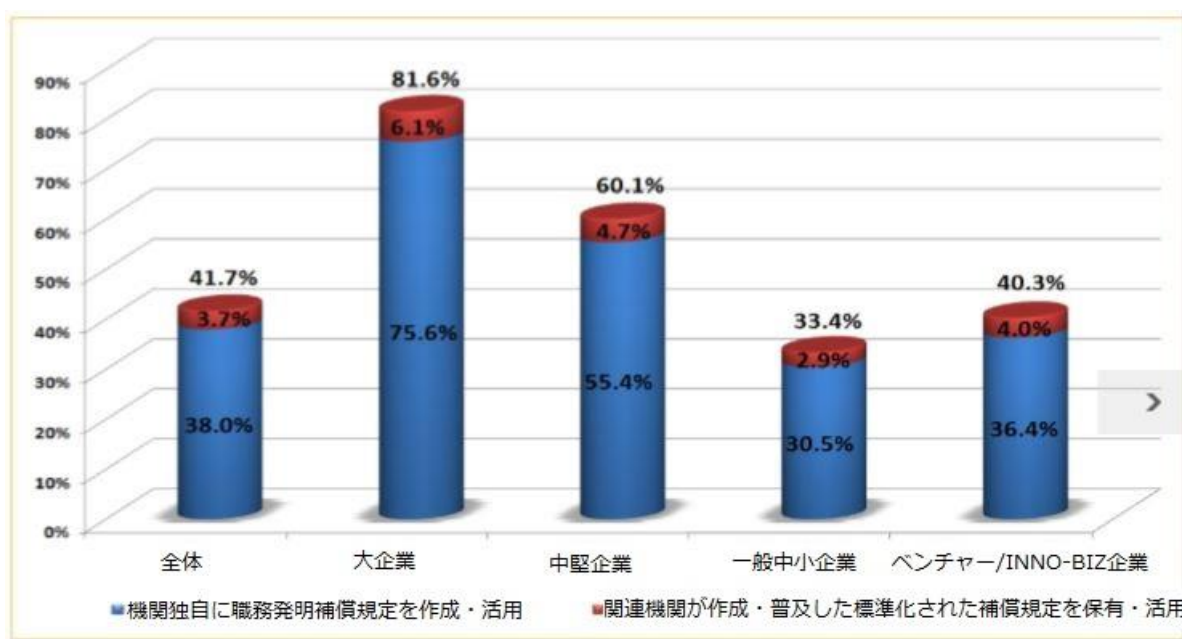
注. 複数回答

企業類型別に見ると、大企業と中堅企業の場合、先行特許(技術)調査の際に弁理士及び弁理士事務所に依頼して行う比率が高く、一般中小企業とベンチャー企業の場合、R&D 人材が行う比率が高いことが分かった。知的財産専門担当人材が該当業務を行う比率は中堅企業が 25.1%で最も高く、大企業の場合も 22.5%で一般中小企業、ベンチャー企業に比べて相対的に高いことが分かった。一方、年平均 61 件以上の多出願企業の場合は R&D 人材よりは弁理士及び弁理士事務所が該当業務を行う比率が高いことが分かった。<sup>23</sup>

<sup>23</sup> 年平均61件以上出願企業の48.7%はR&D人材が遂行、61.7%が弁理士及び弁理士事務所が遂行。

## 2. 職務発明補償

職務発明補償規定を保有・活用している企業の比率は 41.7% (既存母集団基準による標本調査の結果 51.5%)<sup>24</sup>となっている([図 2.13])。これを細分化すると、機関が独自に職務発明補償規定を作成して活用している比率が 38.0% (47.4%) であり、特許庁など関連機関が作成・普及・標準化した職務発明補償規定を保有・活用している比率は 3.7% (4.1%) であることが分かった。



[図 2.13] 職務発明補償規定の保有及び活用状況

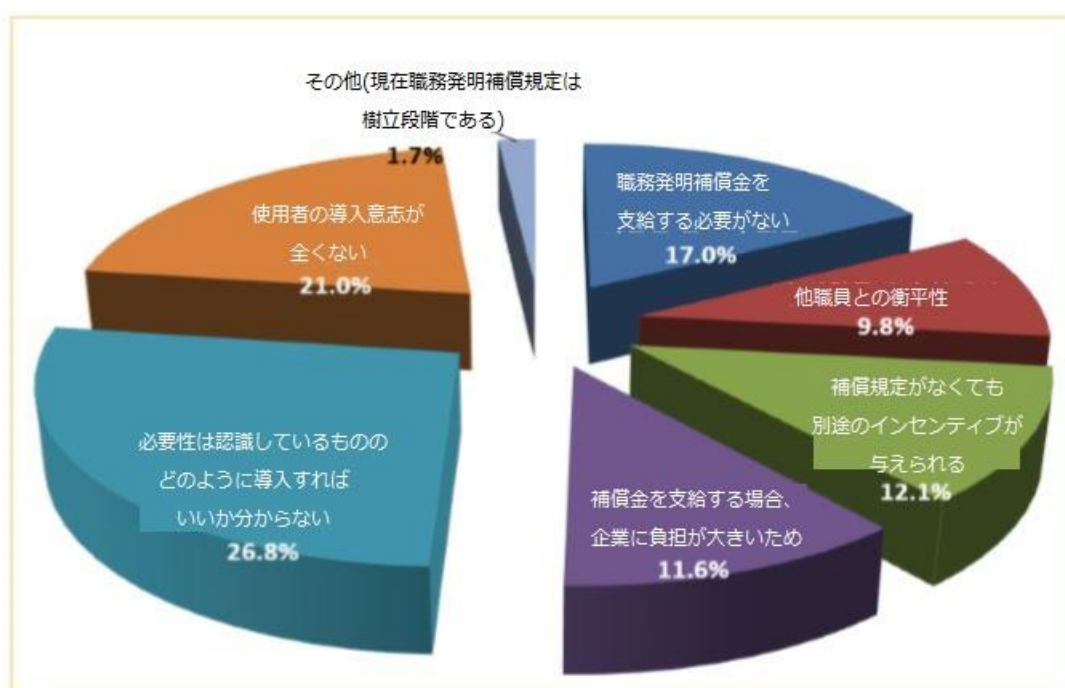
注. 2010 年度既存母集団の推定値である。

企業類型別では大企業の 81.6% (84.4%) が職務発明補償規定を保有/活用しており、最も高く、中堅企業の 60.1% (75.0%)、ベンチャー企業の 40.3% (43.1%)、一般中小企業の 33.4% (39.5%) が職務発明補償規定を保有/活用していることがわかった。

<sup>24</sup> 研究者が職務上行った発明に対して会社がその発明に対する特許権を承継し、特許取得と事業化を通じて発生した利益を研究者に補償することを指す。職務発明補償規定の保有状況は特許中心の知的財産活動として第2節の表記方式のように2010年既存母集団推定値を提示し、既存母集団基準による標本調査結果を括弧の中に表示している。



補償規定を保有していない理由は、必要性は認識しているもののどのように導入すればいいかわからないと回答した比率が 26.8% (27.2%)、補償規定がなくても別途のインセンティブが与えられるためと答えた比率が 12.1% (10.4%) を占めている ([図 2.14])。企業類型別に見ると、必要性は認識しているもののどのように導入すればいいかわからないと答えた比率はベンチャー企業 29.9% (28.6%)、一般中小企業 25.3% (27.6%)、中堅企業 23.4% (22.9%)、大企業 6.7% (17.6%) である。相対的にベンチャー企業及び一般中小企業を対象に、職務発明補償規定に関する広報とともに、導入への支援が求められる。



[図 2.14]職務発明補償規定を保有していない場合、その主な理由

注. 2010 年度既存母集団の推定値である。

職務発明補償の類型別実施状況を見ると以下の[表 2.4]のとおりである。国内特許登録補償、国内特許出願補償、海外特許登録補償を実施している比率が其々 89.8%、77.7%、66.9%と高いことが分かった。企業類型別では、大企業の場合は国内特許登録及び国内特許出願補償の場合が其々 91.2%、75.1%で最も高く、中堅企業、一般中小企業、ベンチャー企業の場合にも国内特許登録補償の場合が最も高い比率であった。職務発明に対して金銭的な補償を実施する場合の補償金水準は、国内特許登録補償平

均 114.1 万ウォン、国内特許出願補償平均 51.6 万ウォン、海外特許登録補償平均 124.9 万ウォン、海外特許出願補償平均 65.3 万ウォンとなっている。

[表 2.4]職務発明補償類型別の実施比率

	全体	大企業	中堅企業	一般中小企業	ベンチャー /INNO-BIZ 企業
発明提案(発明届出)補償	44.3%	25.4%	40.2%	49.8%	48.5%
出願留保	32.5%	23.8%	39.6%	36.3%	29.7%
国内特許出願	77.7%	75.1%	83.4%	81.9%	72.8%
国内特許登録	89.8%	91.2%	93.2%	91.7%	86.3%
海外特許出願	56.1%	48.2%	70.4%	60.6%	49.7%
海外特許登録	66.9%	68.8%	79.2%	71.7%	57.3%
その他産業財産権の国内登録	58.0%	63.2%	60.7%	61.5%	51.9%
その他産業財産権の海外登録	46.8%	50.0%	56.1%	53.0%	36.7%
自社実施	43.2%	45.5%	51.2%	36.2%	45.3%
他社実施	25.8%	40.3%	28.7%	26.7%	18.1%
処分	24.0%	38.2%	32.6%	19.9%	18.7%

注. 2010 年度既存母集団推定値である。

職務発明補償と関連する制度の効果と関連し、職務発明に対する補償実施または補償水準の拡大が機関内発明件数及び品質向上と技術流出防止に効果的であると答えた比率が其々 56.1%と 41.4%を占めている。

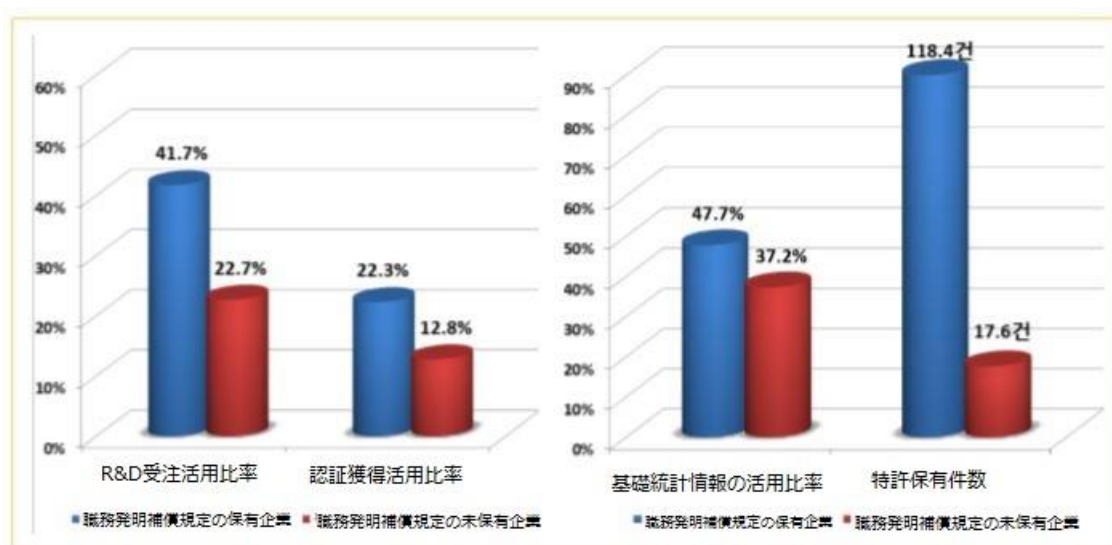
**<職務発明補償規定の保有企業及び未保有企業における知的財産活動の比較>**

職務発明補償規定を保有している企業が産業財産権を R&D の遂行または各種認証の獲得に活用した比率を分析した結果、未保有企業に比べて極めて高いことが分かった。



職務発明補償規定を保有している企業が産業財産権を R&D の遂行及び認証獲得に活用した比率は其々41.7%、22.3%であり、未保有企業の場合は其々22.7%、12.8%であることが分かった。

また、職務発明保有企業の基礎統計情報を活用する比率と平均特許保有件数を調査した結果、未保有企業に比べて高いことが分かった。職務発明補償規定保有企業の場合、基礎統計情報の活用比率と平均特許保有件数は其々47.7%、118.4件であり、未保有企業の37.2%、17.6件に比べて比較的に高いことが分かった([図 2.15])。



[図 2.15]職務発明補償規定の保有企業及び未保有企業の知的財産活動状況

注. 標本調査の結果

### <企業の全体出願件数による職務発明補償規定の保有比率>

職務発明補償規定を保有している企業の比率を企業の全体特許出願件数別に見ると、特許出願が多い企業の保有比率が高いことが分かった。5件以上出願企業の比率は53.9%であり、10件以上出願した企業の比率は60.6%、20件以上出願した多出願企業の場合は職務発明補償規定を保有している企業の比率が70.2%に達していることが分かった([表 2.5])。

[表 2.5]全体特許出願件数による職務発明補償規定の保有比率

企業規模	5件以上	10件以上	20件以上	全体出願

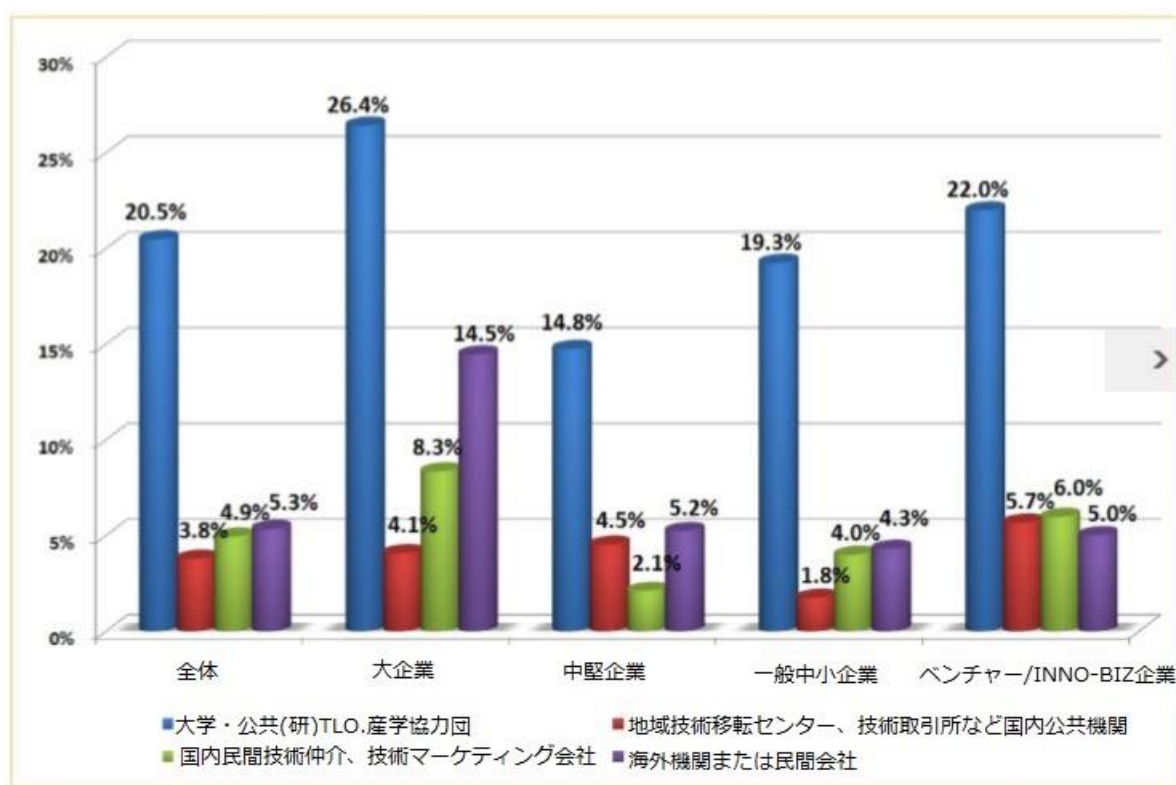
大企業	86.8%	89.1%	90.9%	84.4%
中堅企業	76.5%	80.2%	84.5%	75.0%
一般中小企業	41.8%	48.3%	57.9%	39.5%
ベンチャー/INNO-BIZ 企業	43.9%	48.2%	55.3%	43.1%
全体	53.9%	60.6%	70.2%	51.5%

注：標本調査の結果。但し、基準年度に特許出願がない企業は除外。

### 3. 技術取引機関、技術マーケティング会社との協力

最近 3 年間技術取引及び技術マーケティングのために技術取引機関へ業務を依頼、もしくは協約を締結した企業の比率は[図 2.16]のとおりである。全体企業の 20.5%が大学・公共研究機関の技術移転専門担当組織(TLO)及び産学協力団に業務を依頼したことがあると答えている。また、地域技術移転センターなど国内公共機関、国内民間技術仲介会社、海外機関に業務を依頼した企業の比重は其々3.8%、4.9%、5.3%となっている。

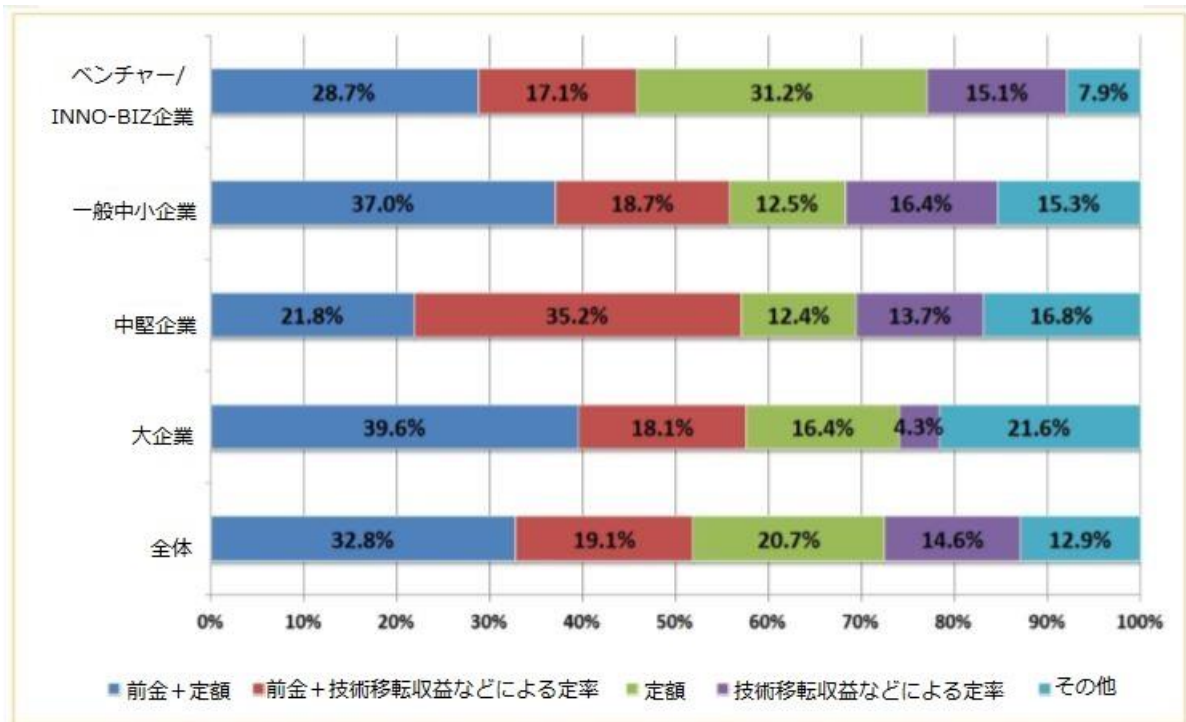
企業類型別では大学・公共研究機関の技術移転専門担当組織(TLO)及び産学協力団に依頼した比率は全ての企業類型において高い。一方、海外機関または民間会社に依頼した比率は他企業類型に比べて大企業で極めて高いことが分かる。地域技術移転センターなど国内公共機関に依頼した比率はベンチャー企業が 5.7%で最も高く、国内民間技術マーケティング会社に依頼した比率は大企業が 8.3%、ベンチャー企業が 6.0%、一般中小企業が 4.0%、中堅企業が 2.1%となっている。



[図 2.16] 最近 3 年間技術取引機関に対する業務依頼及び締結状況

技術取引機関などに業務を依頼した場合、主な費用支払い方法は調査/マーケティング費用など活動費(前金)と成功報酬(定額)が混ざった形態が全体の 32.8%で、その他を除いた項目の中で最も高い比重を占めた([図 2.17])。また、成功報酬として定額を支給する場合は 20.7%、活動費(前金)と技術移転収益などによる定率の成功報酬が混ざった形態で支給する場合は 19.1%となっている。一方、技術移転収益などによる定率の成功報酬のみ費用を支給する場合は 14.6%で最も低い。

企業類型別では、大企業は活動費(前金)と成功報酬(定額)が混ざった形態で費用を支払った比率が全体の 39.6%で最も高く、ベンチャー企業は成功報酬(定額)の形態で支給した場合が 31.2%で他企業類型に比べて高い。これは技術移転費用を支給するに当たって、大企業は活動費(前金)と成功報酬(定額)が混ざった形態を好み、ベンチャー企業は成功報酬(定額)形態を好んでいるものと解釈できる。



[図 2.17] 技術取引機関などに業務を依頼した場合の主な費用支給方法

企業が保有している知的財産取引のために IP-mart<sup>25</sup>など国内オンライン技術取引システムを活用している企業の比率は全体の 27.0%となっている([表 2.6])。国内オンライン取引システムを活用している企業のうち活用度が比較的に高いと肯定的に答えた比率は 11.0%となっている。

企業類型別に見ると、ベンチャー企業の場合は国内オンライン及びオフライン取引システムを活用している比率が他企業類型に比べて高く、海外オンライン及びオフライン取引システムの活用率も高い方である。しかし、活用企業に限って活用度の調査結果の活用度は比較的に低い方である。

[表 2.6] 国内技術取引システムの活用度

	全体	大企業	中堅企業	一般中小	ベンチャ

<sup>25</sup> IP-martは特許庁が運営しているインターネット特許技術市場であり、特許技術の技術移転・取引及び事業化など関連情報を提供し、利用者が自律的に技術取引に参加できるよう、オンライン上で特許技術取引を仲介する専門ポータルサイト(<http://www.patentmart.or.kr/>)である。

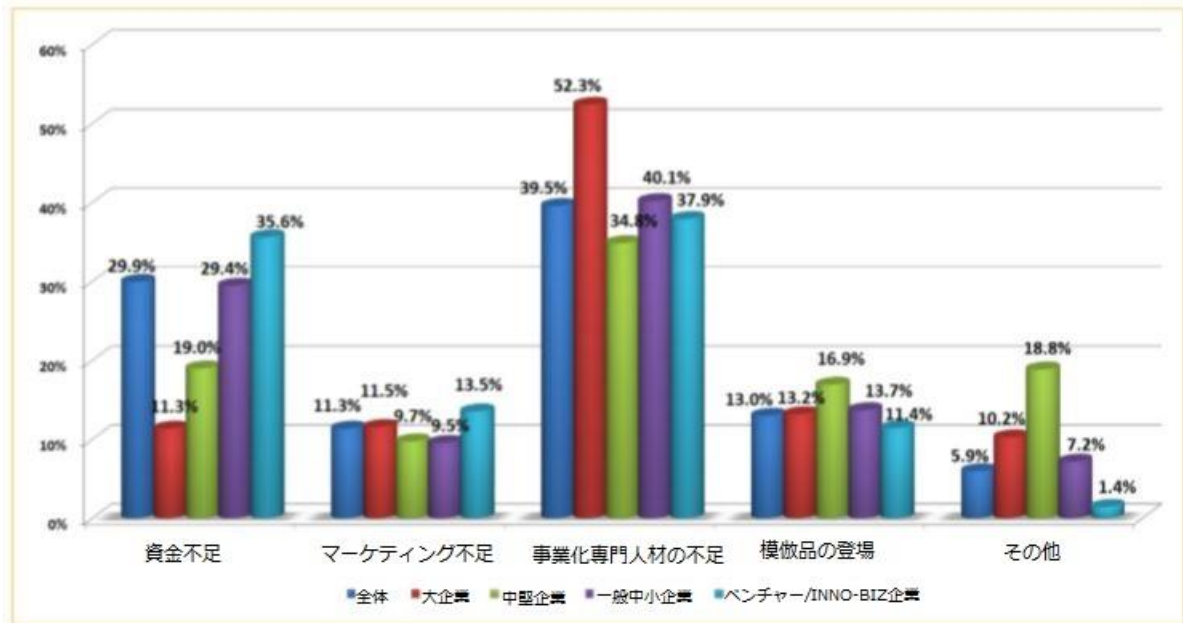
					企業	一/INNO- BIZ 企業
国内オンライン 取引システム	活用企業	27.0%	23.1%	22.8%	26.3%	29.2%
	活用度が比較的に高い	11.0%	10.9%	11.9%	13.6%	8.4%
国内オフライン 取引システム	活用企業	24.0%	16.5%	23.1%	21.6%	27.7%
	活用度が比較的に高い	11.7%	31.7%	21.6%	10.0%	9.6%
海外オンライン 取引システム	活用企業	17.4%	13.8%	18.4%	13.7%	21.5%
	活用度が比較的に高い	5.4%	7.3%	19.3%	0.9%	5.7%
海外オフライン 取引システム	活用企業	17.3%	14.2%	18.6%	13.8%	21.1%
	活用度が比較的に高い	7.3%	41.8%	21.8%	3.9%	3.5%

注. 「活用度が比較的に高い」は 5 点尺度(1:活用度が低い、5:活用度が高い)で  

$$[(4 \text{ と } 5 \text{ で回答した企業数}) / (\text{活用した経験のある企業数})] \times 100(\%)$$

特許技術移転博覧会など国内オフライン取引システムを活用している企業の比率は 24.0%でオンライン取引システムより多少低いことが分かった。また、実際オフラインシステムを活用している企業のうち活用度が高いと答えた比率は 11.7%でオンライン取引システムより高い。企業類型別では、ベンチャー企業が活用率の面で最も高く、活動度は大企業の方が高いことがわかった。

企業にとって特許技術の事業化における最も大きな問題として、全体の 39.5%が事業化専門人材の不足を挙げている([図 2.18])。また、資金不足によって事業化が難しいと答えた企業も 29.9%を占めている。



[図 2.18] 特許技術の事業化における最大の問題点

事業化における問題点として事業化専門人材の不足を指摘した比率は大企業 52.3%、一般中小企業 40.1%、ベンチャー企業 37.9%、中堅企業 34.8%の順であり、資金不足を挙げた企業の比率は大企業 11.3%、中堅企業 19.0%、一般中小企業 29.4%、ベンチャー企業 35.6%の順であることが分かった。

### 第3節 知的財産の創出及び活用

#### 1. 知的財産基礎統計情報及び情報システム

知的財産統計など基礎統計情報を活用している比率は全体の 35.2% (37.8%) となっている ([図 2.19])。機関類型別では、中堅企業の活用比率が 56.4% (59.8%) と最も高く、大企業 44.4% (46.7%)、ベンチャー企業 38.0% (37.9%)、一般中小企業 28.9% (32.1%) と続いている。

主に活用している統計指標に関する調査項目では「産業部門別出願件数」を利用する割合が回答者の 31.2% (32.3%) であり、「年度別出願件数」を主に活用する比率が 14.4% (15.4%) となっている。

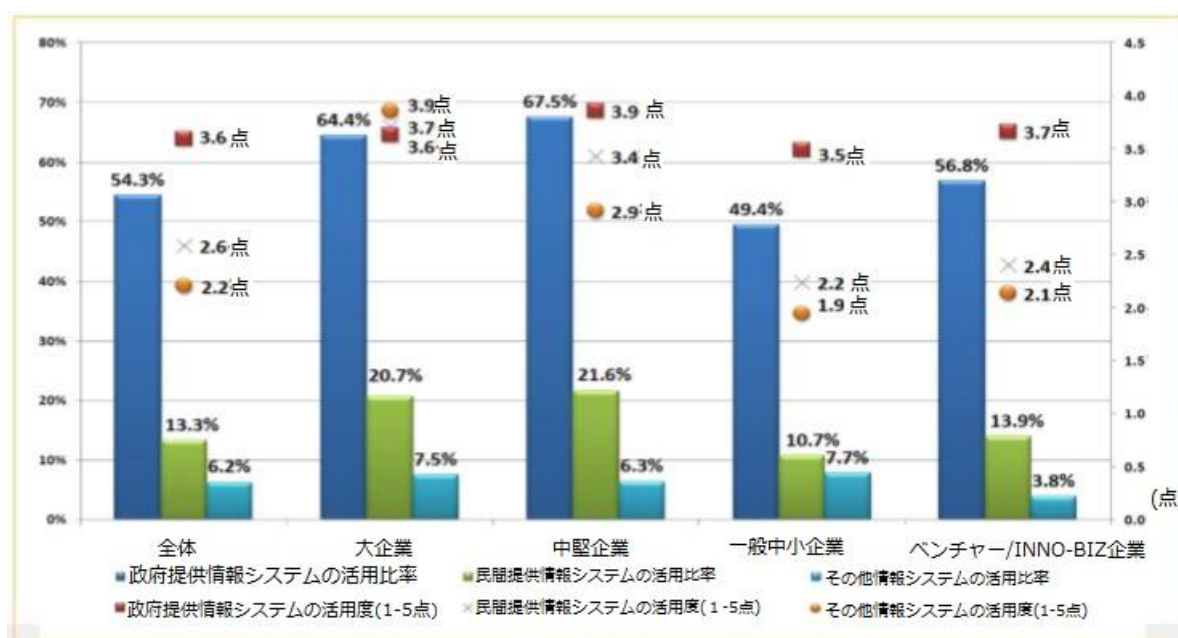


[図 2.19] 知的財産基礎統計情報の活用状況

政府または民間が提供する知的財産情報システムに対する活用度を見ると、まず政府が提供する知的財産情報システムを活用していると答えた比率は 54.3% (58.3%) となっている ([図 2.20])。活用している企業の平均活用度 (5 点尺度) は 3.6 点 (3.7 点)

となっている。企業類型別に見ると、中堅企業の 67.5% (74.4%) が情報システムを活用していると答え、中小企業の 49.4% (53.9%) に比べて高いことがわかる。

民間が提供する知的財産情報システムを活用していると答えた比率は 13.3% (16.5%) となっている ([図 2.14])。活用している企業の平均活用度は 2.6 点 (同一) となっている。企業類型別に見ると、中堅企業 21.6% (25.0%)、大企業 20.7% (26.0%)、ベンチャー企業 13.9% (15.6%)、中小企業 10.7% (14.3%) と続いている。その他情報システムの場合 6.2% (6.6%) が活用していると答え、中小企業 7.7% (9.2%)、大企業 7.5% (8.4%)、中堅企業 6.3% (6.1%)、ベンチャー企業 3.8% (同一) となっている。

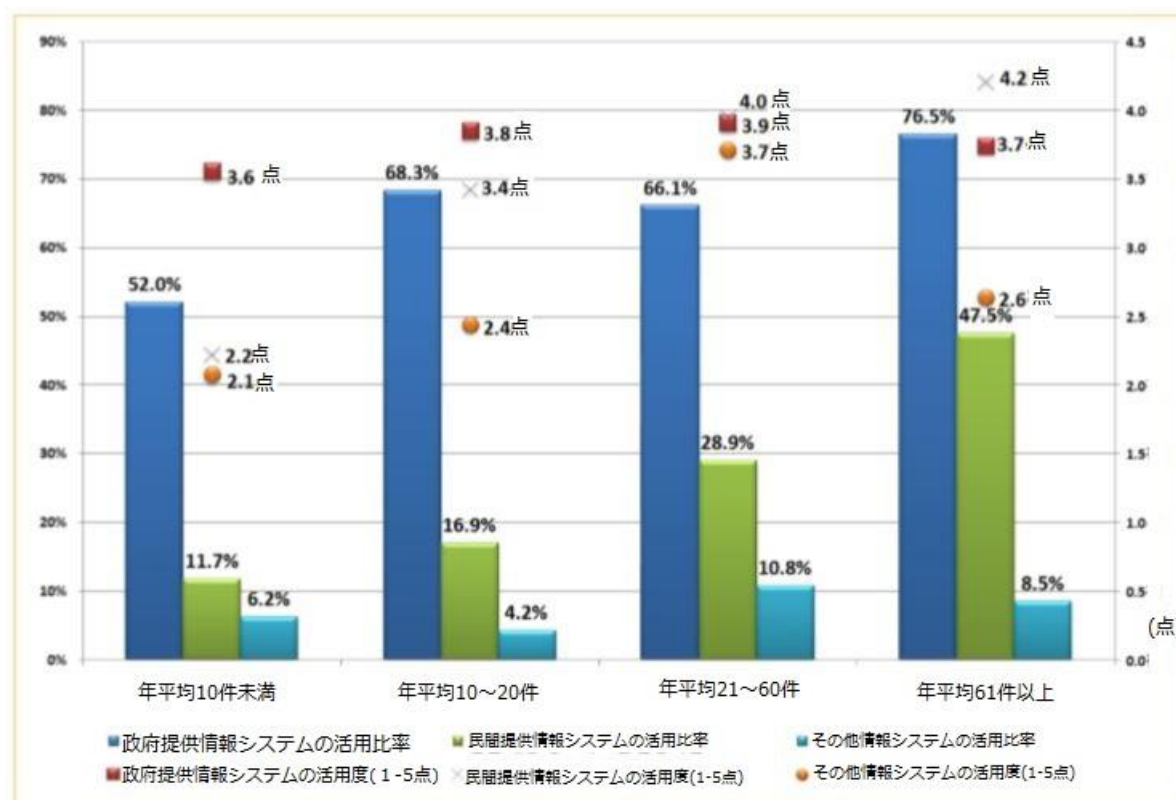


[図 2.20] 企業類型別の知的財産情報システムの活用

出願規模別に政府が提供する知的財産情報システムの活用比率を見ると、年平均 10 件未満企業の場合 52.0% (55.7%) が活用していると答え、10～20 件出願企業が 68.3% (71.0%)、21～60 件出願企業が 66.1% (75.1%)、61 件以上多出願企業の場合 76.5% (同一) となっている ([図 2.21])。多出願企業の活用比率が最も高く、知的財産が多いほど情報システムの活用比率が高いことがわかる。主に活用している政府提供情報システムとしては「KIPRIS」が 95.0% (95.1%) で最も高い。



民間が提供する知的財産情報システムの活用比率もまた出願規模が大きくなるにつれ、其々活用比率が 11.7% (14.3%)、16.9% (21.1%)、28.9% (38.7%)、47.5% (51.5%)と増加している。主に活用している民間提供情報システムの場合、「WIPS」が 92.7% (同一)で最も高い。その他情報システムとしては「IPMS」が 72.1% (66.9%)で最も高く、「世界国家別特許庁」を活用している場合が 5.4% (7.5%)となっている。

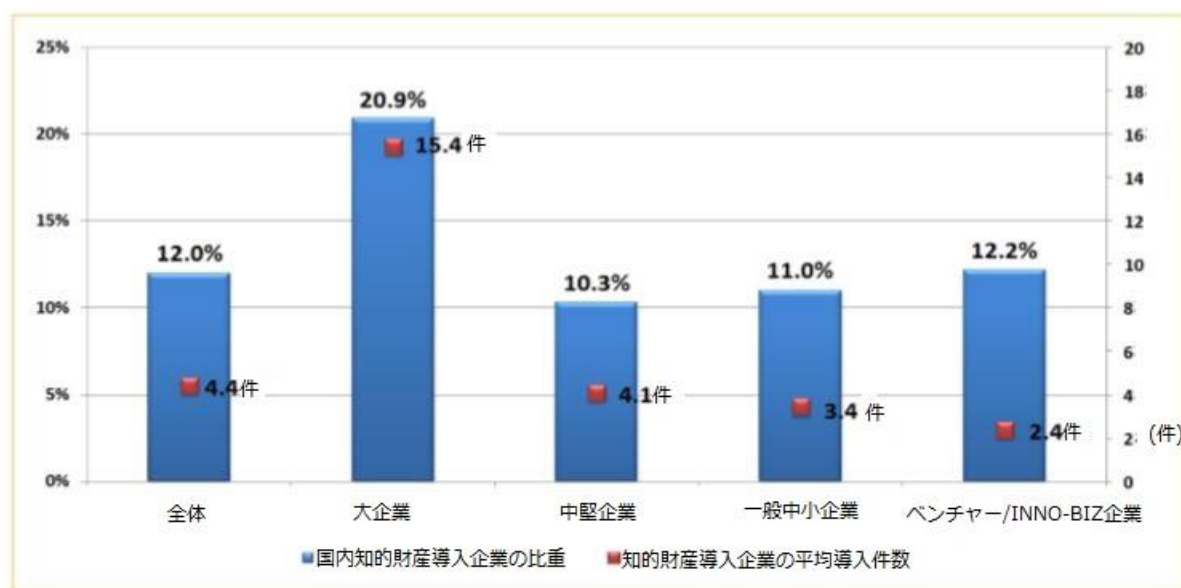


[図 2.21] 出願規模別の知的財産情報システムの活用

## 2. 外部からの知的財産導入実績及び今後の計画

2013 年の 1 年間国内から知的財産を導入した企業は全体の 12.0% (13.3%) となっている ([図 2.22])。企業類型では、大企業の 20.9% (28.0%)、中堅企業の 10.3% (11.0%)、一般中小企業の 11.0% (12.5%)、ベンチャー企業の 12.2% (12.3%) が国内から知的財産を導入したことが分かった。

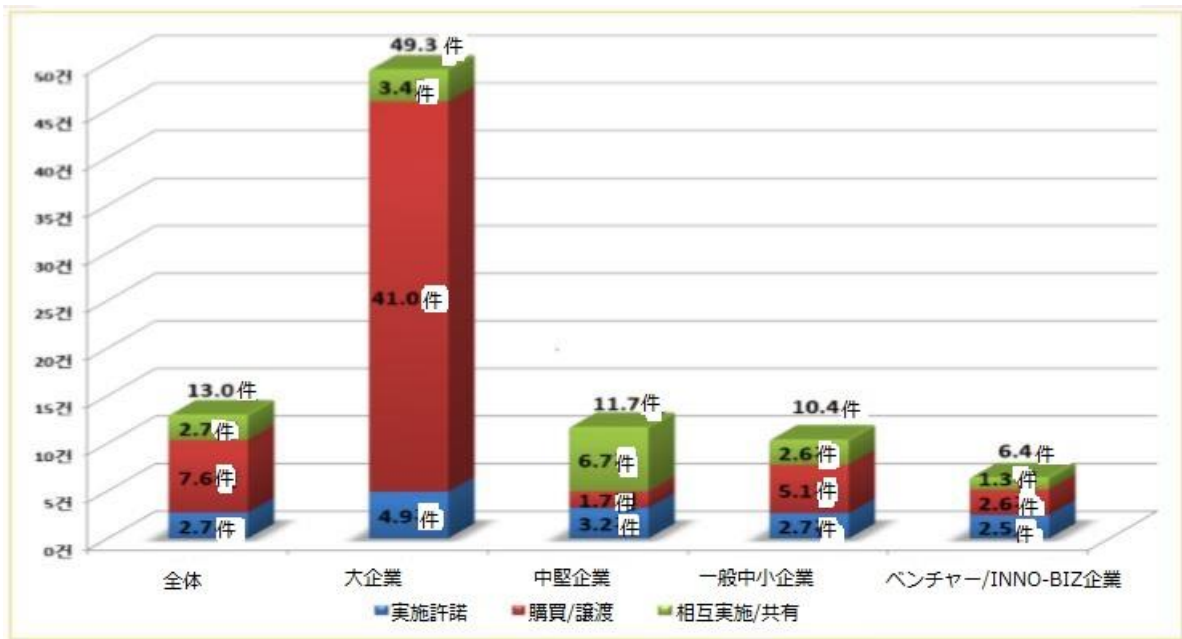
また、国内から知的財産を導入した企業の平均導入件数は 4.4 件(4.4 件)、全体企業の平均は 0.5 件(0.6 件)となっている。企業類型別では大企業、中堅企業、一般中小企業、ベンチャー企業の場合、知的財産を導入した企業の平均知的財産導入件数は 其々15.4 件(14.3 件)、4.1 件(4.5 件)、3.4 件(2.9 件)、2.4 件(2.3 件)となっている。



[図 2.22]国内知的財産導入企業の比率及び平均導入件数

注. 件数は知的財産を導入した企業の平均である。

導入した知的財産を類型別に見ると、平均的に 7.6 件(7.3 件)の知的財産を購買/譲受の形で導入しており、中堅企業を除いた残りの企業類型で最も高いことが分かった([図 2.23])。また、実施許諾、相互実施/共有の形で導入した件数も平均其々2.7 件(3.1 件)、2.7 件(2.2 件)となっている。



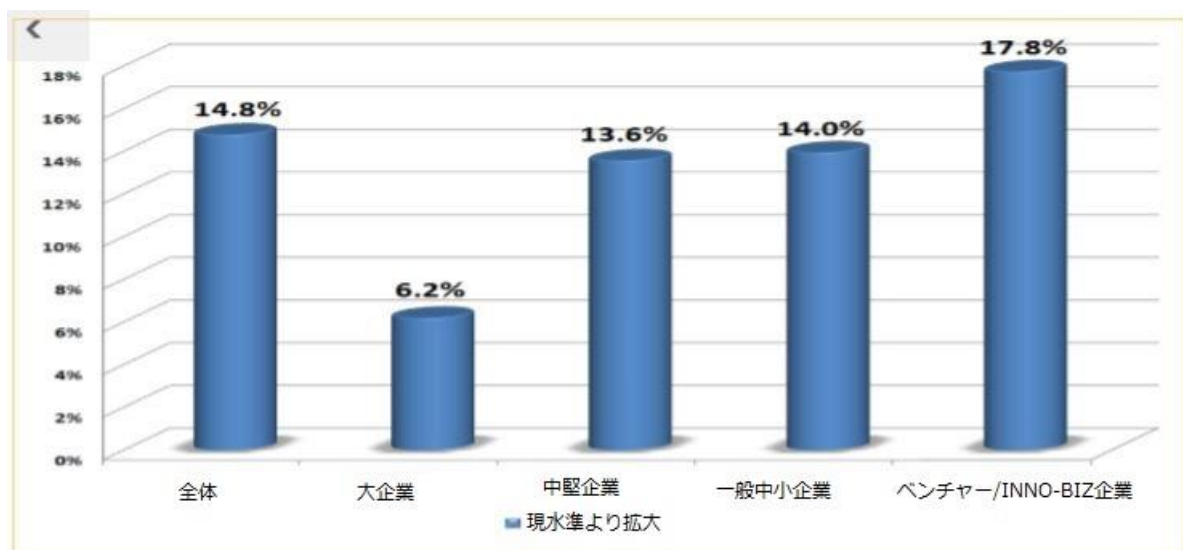
[図 2.23] 知的財産を導入した企業の類型別導入件数

最近 3 年間外部から知的財産を導入した企業の比率は[表 2.7]のとおりである。国内その他企業から知的財産を導入した企業の比率は 4.2% (4.8%) で最も高く、その他に国内大学 4.0% (4.1%)、出捐(研)など公共研究機関が 2.4% (3.4%) と続いている。

[表 2.7] 最近 3 年間外部から知的財産を導入した企業の比率

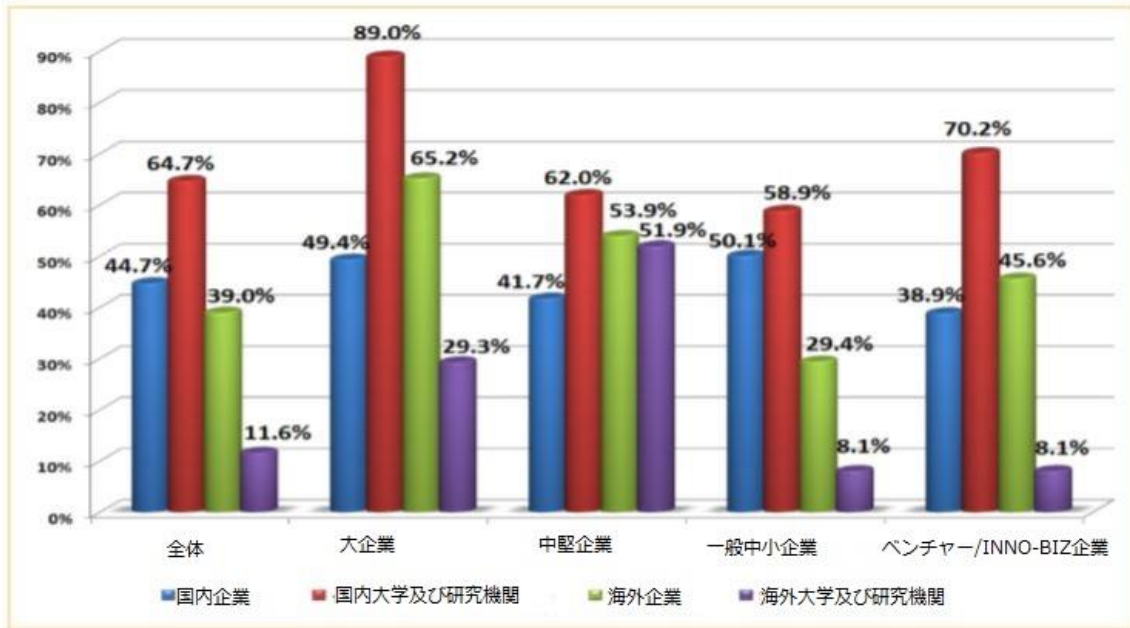
	全体	大企業	中堅企業	一般中小企業	ベンチャー/INNO-BIZ企業
国内グループ系列会社	0.9%	4.2%	0.8%	0.6%	0.7%
国内需要(納品)/供給(下請)企業	2.0%	3.8%	4.1%	1.7%	1.8%
国内その他企業	4.2%	10.7%	1.4%	4.0%	3.9%
国内大学	4.0%	4.4%	4.2%	3.4%	4.7%
出捐(研)など公共研究機関	2.4%	3.4%	2.7%	1.7%	3.2%
海外企業	0.8%	1.3%	3.5%	0.6%	0.5%
海外大学・研究所	0.4%	0.0%	0.3%	0.1%	0.9%

一方、今後外部からの知的財産導入を拡大すると答えた比率は全体の 14.8% (16.6%) となっている ([図 2.24])。これは縮小すると答えた比重である 3.5% (4.1%) より高い数値である。企業類型別ではベンチャー企業の導入拡大予定比率が 17.8% (16.9%) で最も高く、出願件数の多い多出願企業であるほど高いことが分かった。



[図 2.24] 知的財産導入を拡大する予定の企業比率

知的財産導入に向けた投資拡大を計画している場合、国内大学及び公共研究機関からの知的財産導入を拡大すると答えた企業が 64.7% (65.1%) で最も多く、国内企業からの知的財産導入を拡大すると答えた企業の比率は 44.7% (47.8%) と続いている ([図 2.25])。また、海外企業からの知的財産導入を拡大する計画を立てている企業の比率も 39.0% (43.5%) となっている。



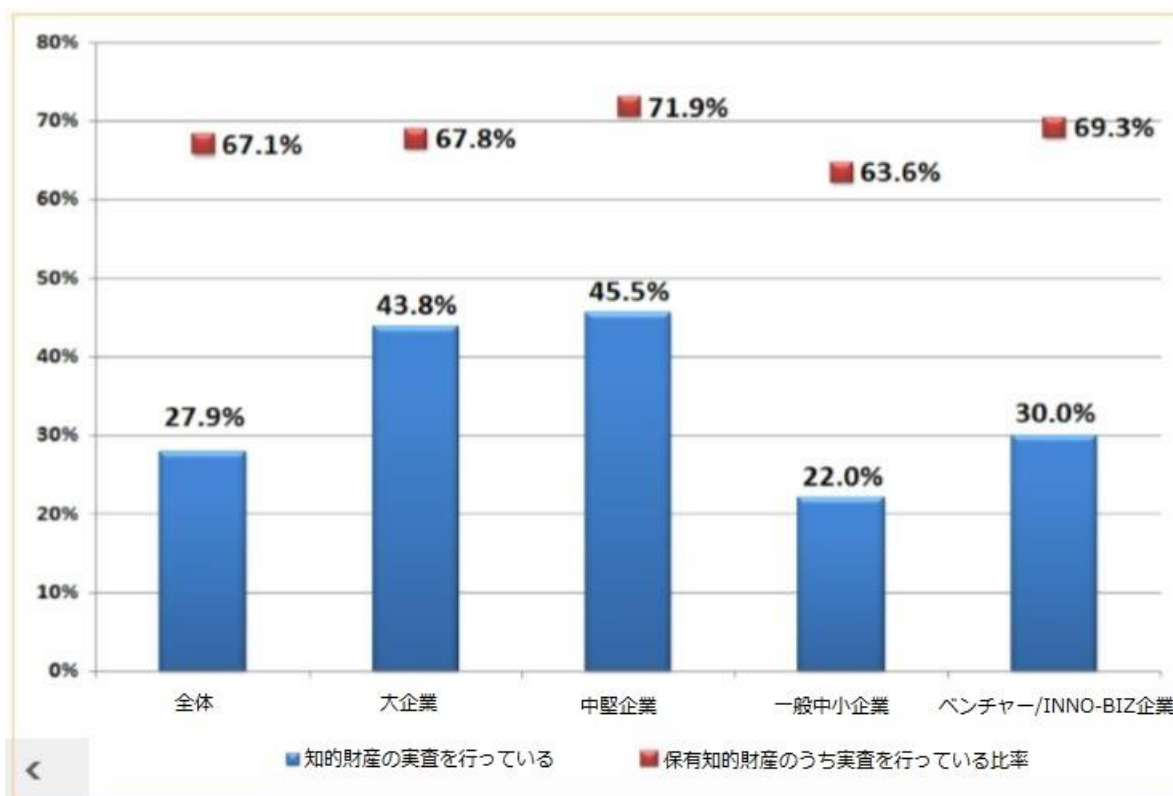
[図 2.25] 知的財産導入に向けた投資拡大の方向

注. 複数回答

企業類型別に見ると、知的財産の導入拡大を計画している大企業とベンチャー企業の場合国内大学及び研究機関から知的財産を導入すると回答した比率が其々89.0% (95.4%)、70.0% (69.3%)、海外企業から知的財産を導入すると答えた比率が65.2% (65.3%)、45.6% (51.6%)となっており、国内企業または海外大学及び研究機関から知的財産を導入しようとする比率に比べて相対的に高い。一般中小企業の場合もやはり国内大学及び研究機関からの知的財産導入比率が58.9% (59.9%)と高いことが分かった。即ち、大企業、中堅企業、中小企業、ベンチャー企業、全て国内大学及び研究機関からの知的財産導入を拡大しようとする傾向が強いものと見られる。但し、中堅企業の場合、海外の大学及び研究機関から知的財産を導入する比率が51.9% (51.6%)で相対的に他の企業類型に比べて高いことが分かった。

### 3. 保有知的財産の実査状況

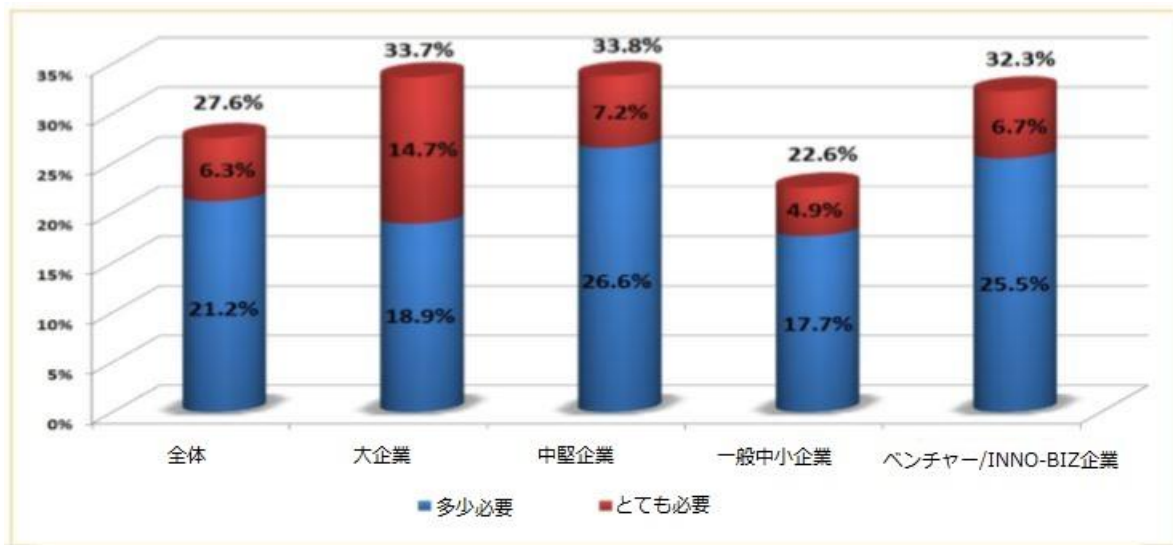
保有している知的財産に対する実査及び評価<sup>26</sup>を行っている企業の比率は全体の27.9% (36.0%)となっている([図 2.26])。知的財産実査を行っていると答えた企業は平均的に保有している知的財産のうち67.1% (63.8%)に対して実査を行っていることが分かった。



[図 2.26] 知的財産実査の実施状況

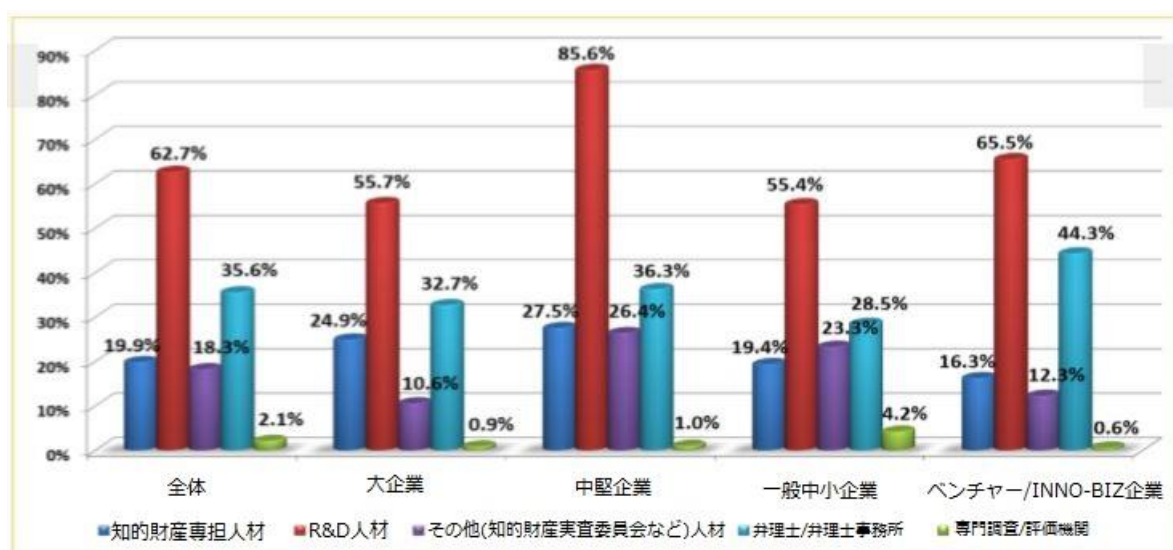
企業類型別に見ると、中堅企業の場合知的財産に対する実査を行っている比率が他の企業類型に比べて高く、保有知的財産の中で実査を行っている比率もまた中堅企業が最も高いことが分かった。

<sup>26</sup> 特許などの維持/放棄の決定、事業化有望技術及び移転対象技術などを発掘するために保有している知的財産の価値を把握することを意味する。



[図 2.27] 知的財産実査の必要性

保有している知的財産に対する実査が必要またはとても必要であると回答した企業の比率は全体の 27.6% (30.7%) となっている ([図 2.27])。即ち、全体企業の約 72.4% (69.3%) が知的財産実査の必要性に対して認識していないことを物語っている。中堅企業の場合 33.8% (38.9%) が知的財産実査が必要であると答え、大企業の場合 33.7% (38.8%) が知的財産実査が必要であると答えた。特にとても必要であると答えた企業の比率は大企業が 14.7% (14.5%) で最も高くなっている。また、多出願企業であるほど該当業務が必要であると答えた企業の比率が高い。



[図 2.28] 知的財産実査を行っている場合の遂行人材



注. 複数回答

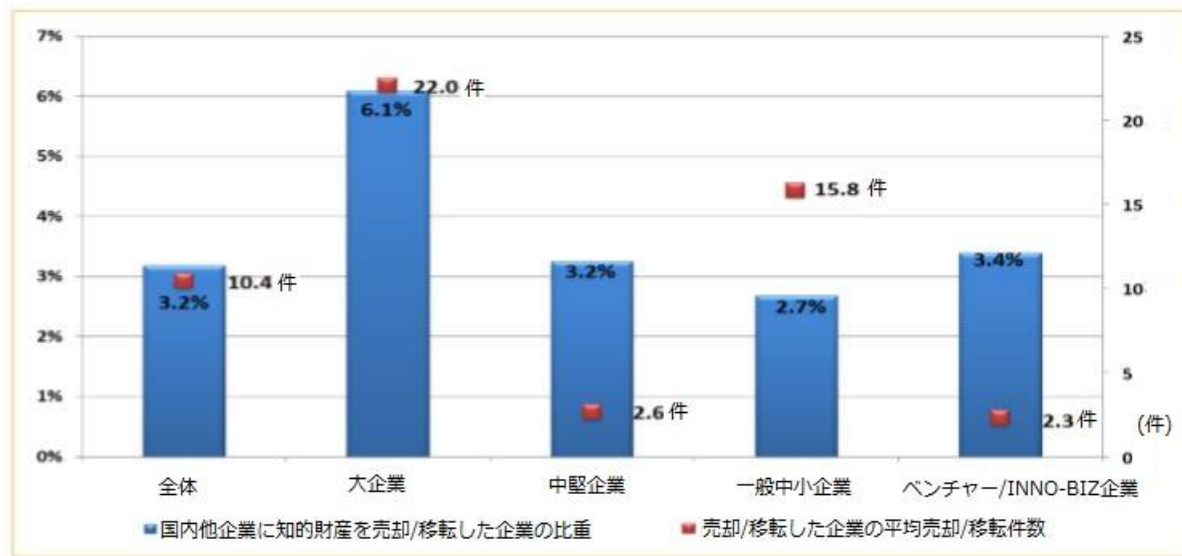
知的財産実査を行っている企業のうち 62.7% (66.8%) は研究開発人材が直接該当業務を担当していること答えている ([図 2.28])。弁理士及び弁理士事務所に該当業務を依頼して遂行していると答えた場合は 35.6% (35.5%) となっており、知的財産専門担当人材が実査業務を行っている と答えた企業は 19.9% (20.3%) となっている。

企業類型別に見ると、知的財産専門担当人材が業務を行っている比率は大企業が 24.9% (29.0%)、中堅企業が 27.5% (25.2%) で相対的に高く、出願件数別に見てもやはり年平均 61 件以上出願企業が 64.4% (63.3%) と高いことが分かった。また、弁理士/弁理士事務所を活用している比率はベンチャー企業が 44.3% (45.6%) で他の企業類型より高く、専門調査/評価機関などの外部人材を活用する比率は一般中小企業が 4.2% (5.1%) で他の企業類型に比べて高いことが分かった。

#### 4. 知的財産権の売却/移転及び活用状況

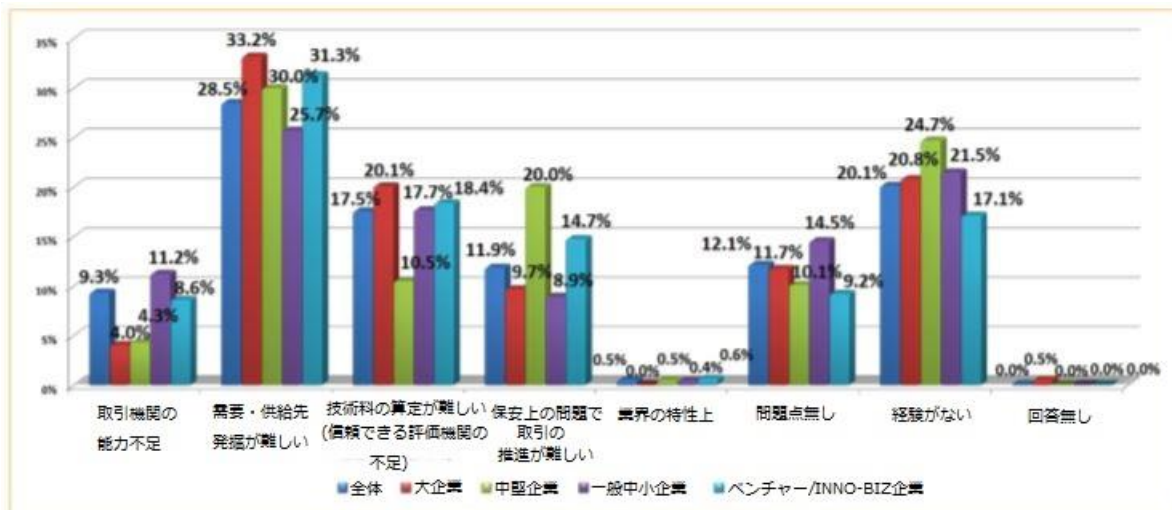
2013 年の 1 年間保有している知的財産を国内の他企業などに売却/移転した企業の比率は 3.2% (3.9%) で、知的財産を売却/移転した企業の平均売却/移転した件数は 10.4 件 (10.1 件) となっている ([図 2.29])。知的財産を売却/移転した企業の比率は企業類型別に見ると、大企業が 6.1% (8.4%) で最も高く、ベンチャー企業 3.4% (3.6%)、中堅企業 3.2% (3.7%) であり、一般中小企業が最も低い。



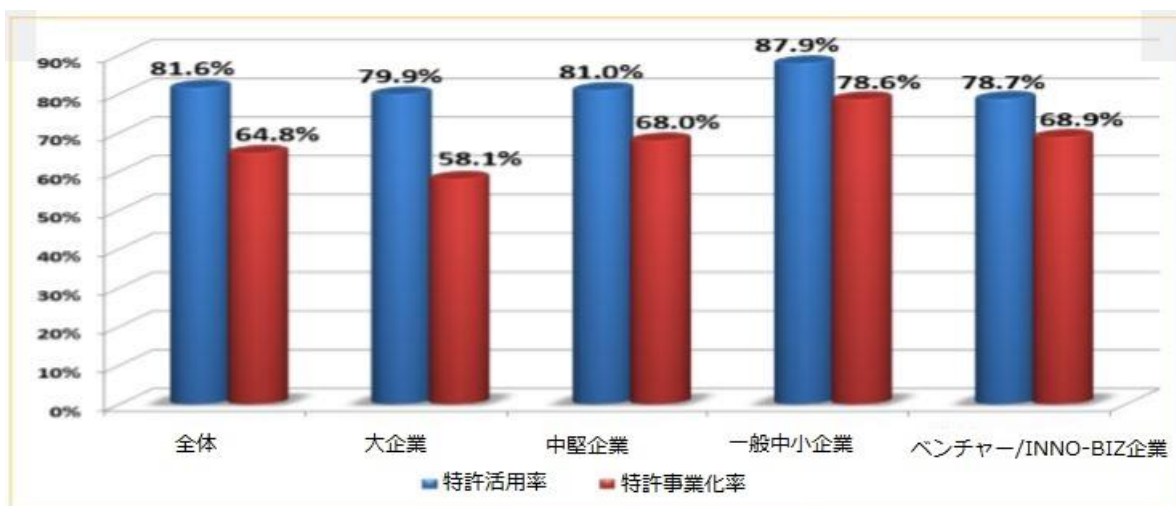


[図 2.29] 知的財産の売却・移転状況

売却/移転した企業の平均売却/移転件数は 10.4 件(10.1 件)であり、このうち売却/譲渡を通じて移転された件数は 3.6 件(3.1 件)、実施許諾を通じた移転件数は 6.1 件(6.4 件)、クロスライセンスや特許プールなどを通じて相互実施または共有形態で移転された件数は 0.7 件(0.6 件)となっている。企業類型別に見ると、大企業と中堅企業、中小企業は全て実施許諾を通じた移転件数が其々 11.7 件(13.7 件)、2.3 件(2.5 件)、10.4 件(10.5 件)で最も多く、ベンチャー企業は売却/譲渡を通じた移転件数が 1.4 件(同一)件で最も多い。知的財産の売却/移転における最も大きな問題点として、全体企業の 28.5%(33.0%)が需要・供給先発掘の難しさを挙げ、20.1%(17.5%)が経験がないという点を問題点として挙げている([図 2.30])。



[図 2.30] 知的財産の売却または移転する上で最大の問題点



[図 2.31] 特許権の活用率及び事業化率

注. 個別企業の活用率及び事業化率の平均である。

全体企業が保有している全特許権のうち、現在活用<sup>27</sup>及び事業化<sup>28</sup>の比率は其々81.6% (81.0%)と 64.8% (63.4%)となっている。<sup>29</sup>企業類型別に見ると、一般中小企

<sup>27</sup> 保有している特許のうち①製品やサービスの生産、工程の改善に活用していたり、②収益創出などを目的として他機関に移転した場合、または③生産活動や技術移転などには直接活用していないものの戦略的な目的(核心技術の防御、特許訴訟の防止、国家レベルでの必要性など)で保有、活用している特許の比率

<sup>28</sup> 保有している特許のうち防御的な目的で活用している場合を除いて製品やサービスの生産、工程改善に活用していたり、収益創出などを目的として他機関に移転した特許の比

業の活用率及び事業化率が 87.9% (同一)、78.6% (78.5%) で最も高いことが分かった ([図 2.31]、[表 2.8])。

[表 2.8] 回答企業が保有している特許の活用件数及び事業化件数、比率

企業区分	保有件数	活用件数	事業化件数	活用率	事業化率
全体	67,906 件	55,379 件	44,002 件	81.6%	64.8%
大企業	37,079 件	29,617 件	21,540 件	79.9%	58.1%
中堅企業	11,161 件	9,035 件	7,594 件	81.0%	68.0%
一般中小企業	13,623 件	11,969 件	10,704 件	87.9%	78.6%
ベンチャー/INNO-BIZ 企業	6,043 件	4,758 件	4,164 件	78.7%	68.9%

## 5. 効果的な知的財産の創出及び活用のために必要な政策支援

効果的に知的財産を創出するために研究者などを対象にした知的財産権関連の教育支援が必要であると回答した企業は 59.8% (50.5%) で最も高く、職務発明補償制度の実施企業に対する税制メリット付与、関連規定の整備支援が必要であると認識している企業の比重が 59.3% (63.8%) となっている。中小企業特許コンサルティング事業の拡大など中小企業の知的財産権創出への支援が必要であると認識している企業は 58.5% (59.9%) となっている ([表 2.9])。その他に特許情報活用拡散事業の拡大など先行特許(技術)調査と特許情報活用支援、多様な技術分野に対する特許マップ構築支援に対する必要性が提起された。

率

<sup>29</sup> 回答した全ての企業が保有する特許を合算し、その中から活用されている比率と事業化されている比率を算出したものである。従って、多出願企業の活用率と事業化率が加重反映されていると言える。

[表 2.9]効果的な知的財産創出のための政策支援の必要性

	全体	大企業	中堅企業	一般中小企業	ベンチャー/INNO-BIZ企業
職務発明補償制度の実施企業に対する 税制メリット付与及び関連規定の整備支援	59.3%	74.6%	66.8%	54.1%	62.5%
特許情報活用拡散事業の拡大など 先行特許調査と特許情報活用支援	58.1%	63.4%	64.9%	52.8%	63.2%
中小企業特許コンサルティング事業の拡大 など中小企業の知的財産権創出支援	58.5%	60.2%	63.6%	53.8%	63.9%
多様な技術分野に対する特許マップ構築支援	52.2%	71.8%	57.1%	44.8%	58.2%
研究者向け知的財産権関連教育の支援	59.8%	75.4%	60.7%	55.5%	63.0%

注：(%)は5点尺度(1：必要性が最も低い、5：必要性が最も高い)で[(4点と5点で答えた企業数)/(総回答機関数)]×100(%)

効果的に知的財産を活用するため、「新技術製品の販路支援及びマーケティング活動支援」が必要であると答えた比率は全体の64.3%(69.0%)で最も高い([表 2.10])。また、「偽造及び模倣品の取締強化」が必要であると答えた比率は61.6%(58.6%)、「新技術の事業化に向けた中小/ベンチャー創業支援」が必要であると答えた比率は61.5%(40.2%)となっている。

企業類型別に見ると、大企業は「地域知識財産センターなどを通じた出願から事業化までの特許総合コンサルティング支援」が必要であると答えた比率が最も高く、一般中小企業とベンチャー企業の場合「新技術製品の販路支援及びマーケティング活動支援」政策に対する必要性が最も高いことが分かり、企業の規模が小さい企業の場合は知的財産の活用において販路を開拓したり、市場に参入することに大きな困難を感じていることが分かった。

[表 2.10] 効果的な知的財産活用のための政策支援の必要性

	全体	大企業	中堅企業	一般中小企業	ベンチャー/INNO-BIZ 企業
新技術製品の販路支援及びマーケティング活動支援	64.3%	62.7%	57.1%	59.9%	72.5%
偽造及び模倣品の取締強化	61.6%	60.4%	56.3%	59.0%	66.6%
新技術の事業化に向けた中小/ベンチャー創業支援	61.5%	53.6%	52.3%	56.7%	71.6%
特許技術の取引・流通システムの改善	52.7%	53.0%	47.8%	50.6%	56.8%
優秀技術の輸出支援	60.1%	67.1%	53.4%	58.0%	63.4%
地域知識財産センターなどを通じた出願から事業化までの特許総合コンサルティング支援	60.4%	70.3%	59.6%	54.8%	66.8%

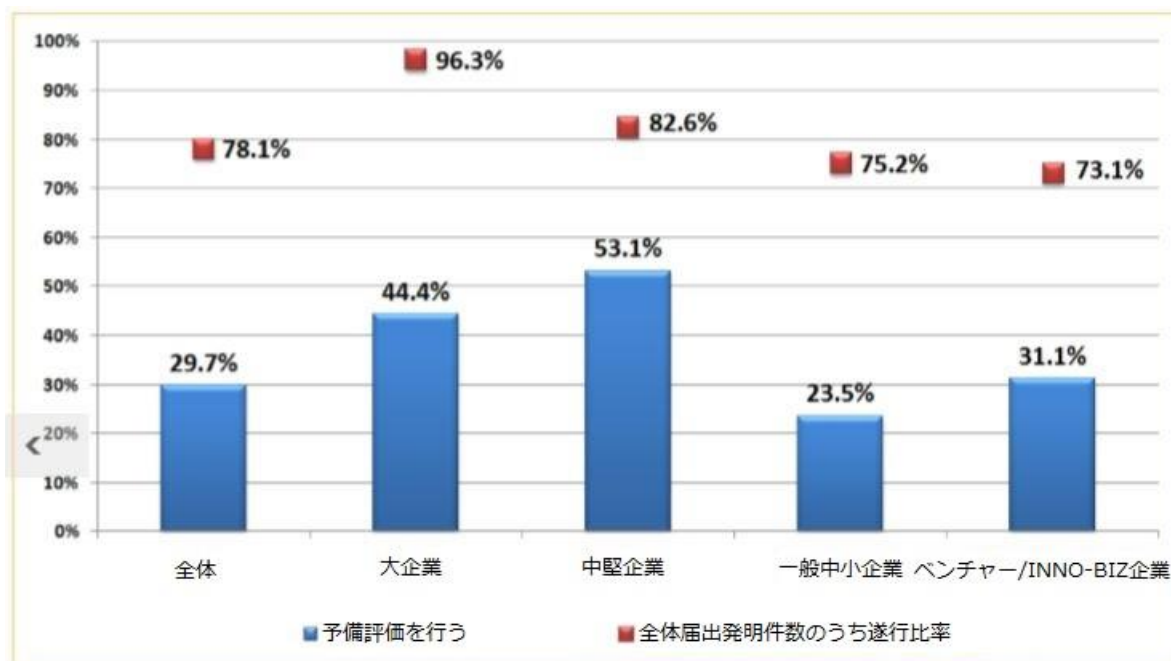
注：(%)は5点尺度(1：必要性が最も低い、5：必要性が最も高い)で[(4点と5点で答えた企業数)/(総回答機関数)]×100(%)

## 第4節 知的財産の保護

### 1. 予備評価の実施状況

産業財産権の出願などに先立ち予備評価<sup>30</sup>を行っている企業の比率は 29.7% (36.6%) であり、平均的に全体発明件数の 78.1% (77.8%) に対して予備評価を行っていると回答した([図 2.32])。

企業類型別では、大企業の 44.4% (51.6%) が発明届出件数のうち 96.3% (96.0%) に対して予備評価を実施していることが分かった。また、予備評価を行う企業の比率は 61 件以上多出願企業が相対的に高いこと<sup>31</sup>がわかった。



[図 2.32] 産業財産権出願前の社内予備評価の実施状況

<sup>30</sup> 「予備評価」とは提出された発明届出書に対して職務発明委員会などを通じて発明の評価、承継状況、出願状況、審査請求状況などを決定することを意味する。

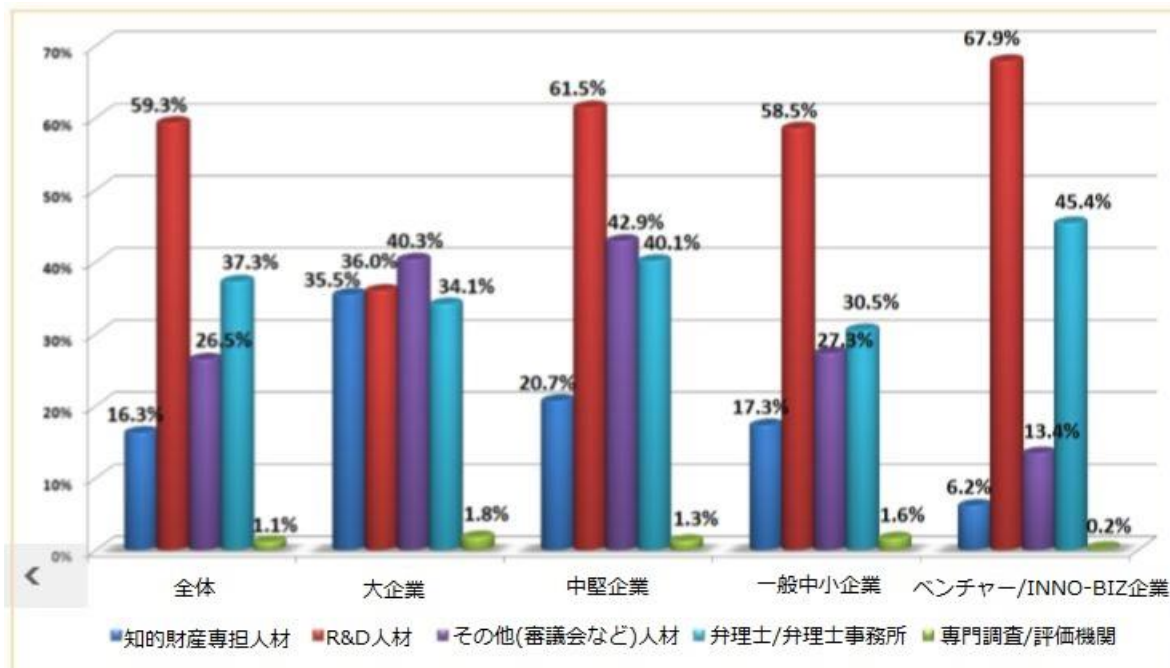
<sup>31</sup> 10件未満出願企業の場合予備評価を行う企業の比率は27.0% (33.0%)、61件以上多出願企業の場合の比率は83.2% (87.9%)。

全体企業の 42.8% (同一) が出願前の予備評価が必要であると答えている ([図 2.33])。これは前述の研究開発企画段階における先行特許(技術)調査が必要であると答えた比率である 63.5% より低い数値である。予備評価が必要であると認識している企業の比率もまた 61 件以上多出願企業が高くなっている。特に、出願する前に予備評価がとても必要であると答えた比率は年 61 件以上出願する企業の場合 21.3% (21.6%) である。企業類型別に見ると、予備評価が必要またはとても必要であると答えた企業の比重は大企業が 52.0% (42.6%) で相対的に高いことが分かった。



[図 2.33] 予備評価実施の必要性

予備評価を担当している人材状況は [図 2.34] のとおりである。予備評価を実施している企業の場合の 59.3% (61.2%)、37.3% (38.4%) は研究開発人材と弁理士/弁理士事務所が該当業務を担当していると答えた。また、その他人材が該当業務を行っている企業の比重は全体の 26.5% (26.9%)、知的財産専門担当人材が行っている場合は 16.3% (19.8%) となっている。



[図 2.34] 予備評価を行っている場合の実行人材

注. 複数回答

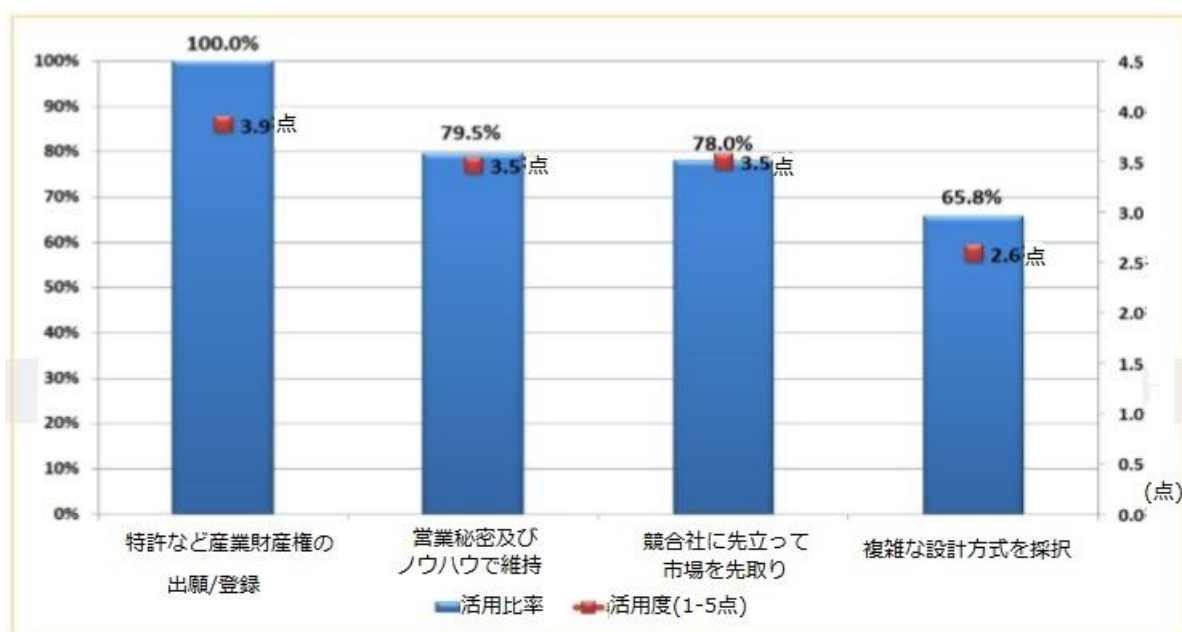
企業類型別に見ると、予備評価を弁理士/弁理士事務所に依頼する比率はベンチャー企業 45.4% (43.0%)、中堅企業 40.1% (39.3%)、大企業 34.1% (24.1%)、一般中小企業 30.5% (39.0%)と続いている。予備評価を知的財産専門担当人材が行う比率は大企業が 35.5% (42.0%)で中堅企業、一般中小企業及びベンチャー企業に比べて高いが、一方研究開発人材が直接予備評価を行うと答えた比率はベンチャー企業が 67.9% (69.8%)で大企業、中堅企業及び一般中小企業より高いことが分かった。また、専門調査/評価機関に依頼する比率は大企業が 1.8% (2.5%)で相対的に高いが、一般中小企業 1.6% (2.2%)及び中堅企業 1.3% (0.6%)、ベンチャー企業 0.2% (0.3%)となっている。全ての企業類型において研究開発人材が直接予備評価を行う比率が外部の弁理士/弁理士事務所に依頼して行う比率より高いが、知的財産専門担当人材が行う比率は大企業を除けば相対的に高くない。内部的に予備評価が行える人材が存在するものの、知的財産を専門的に担当できる専門人材は今後より補完する必要があると見られる。一方、出願件数が多い多出願企業の場合、知的財産専門担当人材が予備評価を行う比率が最も高い。<sup>32</sup>

<sup>32</sup> 年平均61件以上出願企業の58.3% (57.5%)。



## 2. 研究開発成果の保護戦略

研究開発の成果に対する保護戦略として全体企業の 100.0% (同一) が特許など産業財産権の出願/登録を活用していることが分かった([図 2.35])。次に全体の 79.5% (83.8%) と 78.0% (82.9%) が其々研究開発の成果を社内営業機密またはノウハウとして維持したり、競合社に先立って市場を先取りする戦略として活用していることが分かった。また、複雑な設計方式を採択することで研究開発の成果を保護する戦略も全体企業の 65.8% (72.2%) が活用していることが分かった。



[図 2.35] 研究開発成果保護戦略の活用比率及び活用度

注. 複数回答

また、各研究開発成果の保護戦略に対してこれを活用している企業が感じている活用度<sup>33</sup>もまた特許など産業財産権の出願/登録に対する活用度が 3.9 点(4.0 点)で最も高い。また、複雑な設計方法を採用することで研究開発成果を保護する戦略は 2.6 点(2.6 点)で、企業が認識している該当戦略に対する活用度が最も低い。他の保護戦略

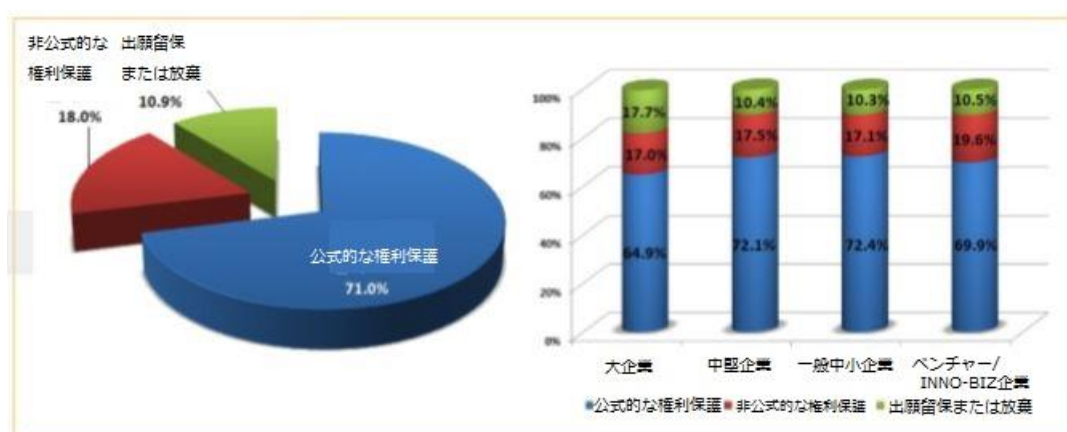
<sup>33</sup> 研究開発成果の保護戦略に対する活用度は5点リッカート尺度で測定されている。

と異なって競合社に先立って市場を先取りする戦略は活用比率に比べて活用度が極めて高いことが分かる。

[表 2.11] 研究開発成果保護戦略の活用度

	全体	大企業	中堅企業	一般中小企業	ベンチャー・INNO-BIZ企業
特許など産業財産権の出願/登録	3.9点	4.0点	4.0点	3.7点	4.1点
営業秘密、ノウハウとして維持	3.5点	3.4点	3.6点	3.4点	3.6点
競合社に先立って市場を先取り	3.5点	3.6点	3.6点	3.5点	3.6点
複雑な設計方法を採用	2.6点	2.5点	2.4点	2.6点	2.6点

全体発明届出件数のうち予備評価などを経て産業財産権の出願など公式的な権利保護手続きを踏むようになる比率は 71.0% (70.8%) となっている ([図 2.36])。また、経済性や技術性の不足などで出願を留保したり放棄する比率は 10.9% (10.5%) で、営業秘密の維持など非公式的な権利保護を進める比率は 18.0% (18.6%) となっている。企業は公式的な権利保護手続きを踏むことによる技術の露出が懸念される場合、営業秘密またはノウハウなど非公式的な権利保護手続きを活用していると見られる。

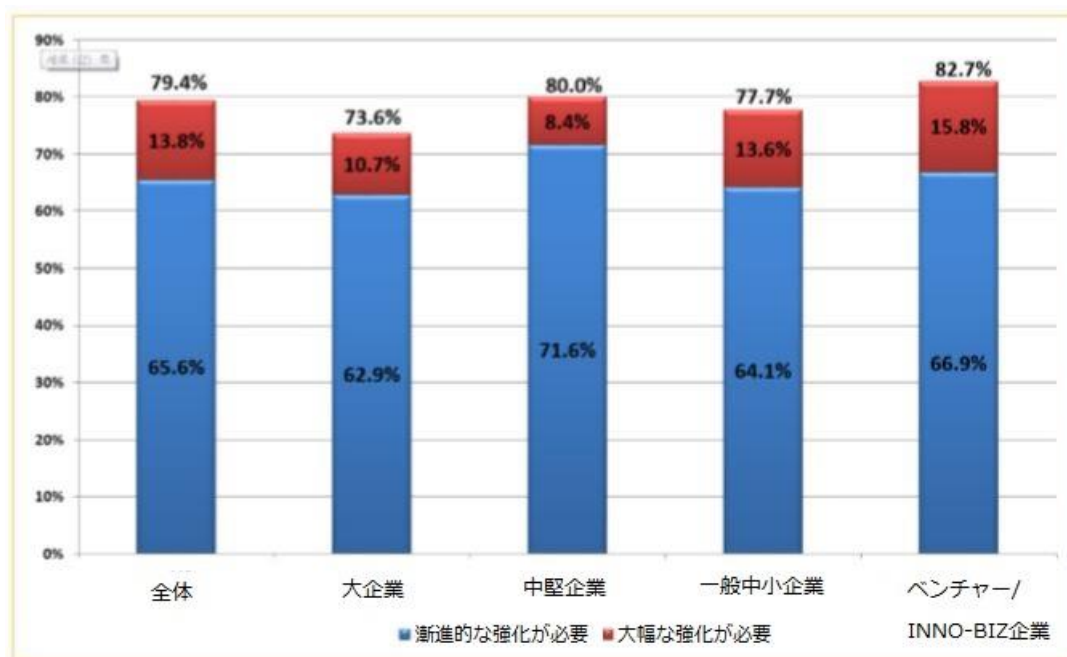


[図 2.36] 公式的/非公式的な権利保護の比率

このような比率は企業類型と出願件数による大きな差異は見当たらない。但し、営業秘密の維持など非公式的な権利保護を展開するようになる比率はベンチャー企業が

19.6% (18.6%)で、中堅企業 17.5% (17.5%)、一般中小企業 17.1% (19.1%)、大企業 17.0% (16.5%)に比べて高い。

韓国企業の 79.4% (81.4%)は国内知的財産保護水準<sup>34</sup>をより強化する必要があると答えている([図 2.37])。<sup>35</sup>これは全体の 79.4% (81.4%)が現在の知的財産保護水準が適切な水準より低いと認識していることを意味する。このような比率はベンチャー企業、年平均出願件数が 61 件以上である多出願企業がより高くなっている。



[図 2.37] 国内知的財産保護水準に対する意見

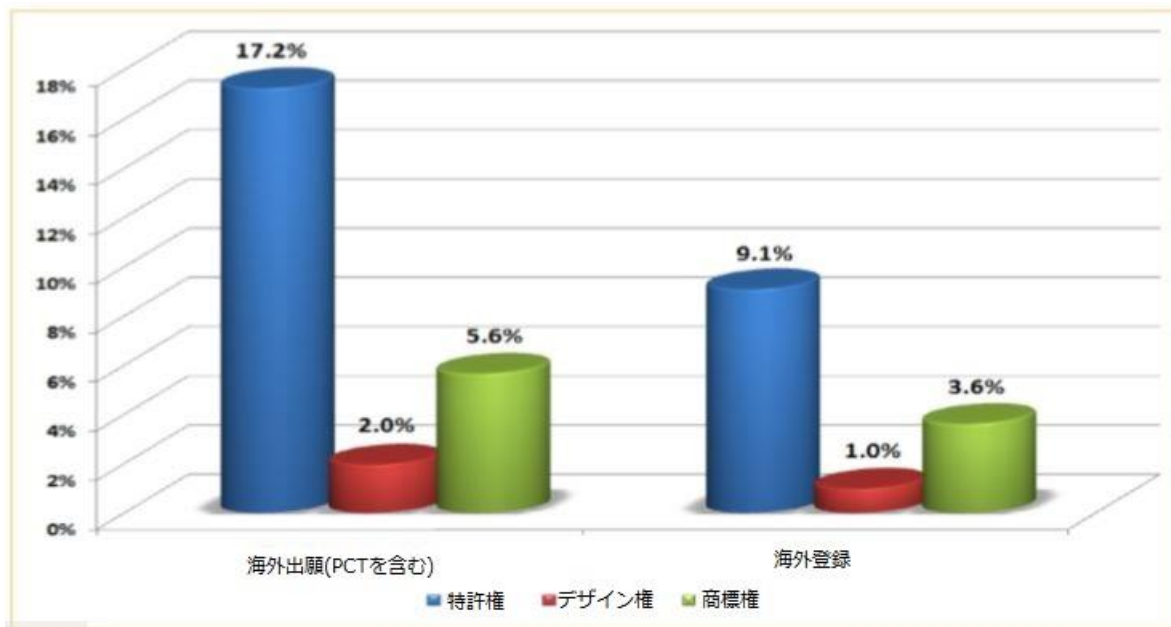
### 3. 産業財産権の海外出願/登録及び国内出願計画

2013 年に 1 件以上の特許権を海外に出願 (PCT を含む) した企業は 17.2% (22.9%) となっている([図 2.38])。また、特許権を海外に登録した企業の比重は 9.1% (12.5%) となっている。特許権の他にデザイン権を海外出願及び登録した企業は其々 2.0%

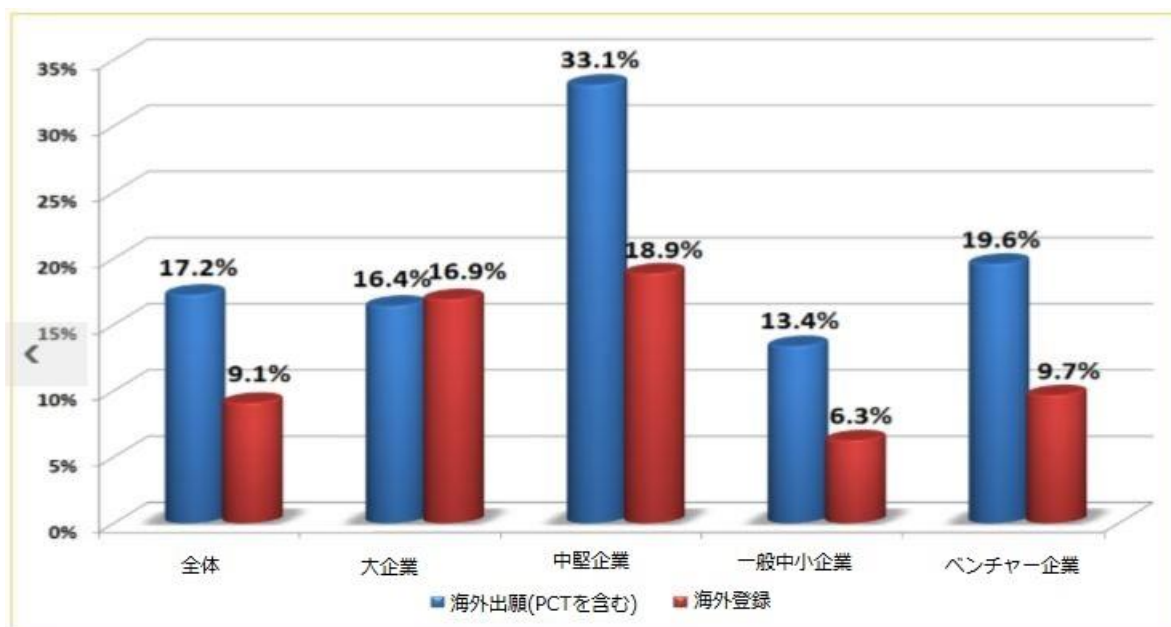
<sup>34</sup> 特許制度のように創出された知的財産に権利を付与するシステムが効率的に運営されているかどうか、そしてこれを通じて成立された知的財産権が他人によって侵害された時に対抗できる効率的な行政的及び司法的措置が十分取られているかどうかを意味する。

<sup>35</sup> 漸進的な強化が必要 (65.6%)、大幅な強化が必要 (13.8%)

(2.2%)と 1.0%(1.3%)、商標権を海外出願及び登録した企業は其々5.6%(4.1%)と 3.6%(2.3%)となっている。



[図 2.38] 特許権の海外出願/登録企業の比重



[図 2.39] 企業類型別の特許権海外出願及び登録企業の比重

企業類型別に見ると、2013年に特許権を海外出願(PCTを含む)及び登録した中堅企業は33.1%(42.6%)、18.9%(24.2%)、大企業は其々16.4%(22.8%)、16.9%(23.5%)、ベンチャー企業は其々19.6%(21.3%)、9.7%(11.0%)、一般中小企業は其々13.4%(20.6%)、6.3%(10.1%)となっている。

一方、2014年に比べて2015年に国内特許出願を拡大する予定であると答えた企業は全体の30.1%(37.4%)で、縮小すると答えた比率の1.0%(1.3%)より遥かに高い水準であることがわかる([表2.12])。企業類型別に見ると、大企業が中堅企業及び一般中小企業、ベンチャー企業に比べて産業財産権の出願を拡大すると答えた比率が低い。

[表2.12]2014年対比2015年の知的財産権出願計画

		全体	大企業	中堅企業	一般中小企業	ベンチャー・ INNO-BIZ企業
特許	縮小	1.0%	2.4%	0.2%	0.9%	1.0%
	拡大	30.1%	21.8%	28.9%	26.1%	37.5%
実用新案	縮小	0.2%	0.9%	0.0%	0.0%	0.4%
	拡大	10.1%	4.1%	9.3%	10.6%	10.8%
デザイン	縮小	0.4%	2.2%	0.2%	0.2%	0.5%
	拡大	15.0%	7.5%	17.3%	15.2%	15.6%
商標	縮小	0.1%	1.3%	0.4%	0.1%	0.0%
	拡大	14.9%	10.1%	15.4%	16.5%	13.2%

[表2.13]産業財産権の国内出願増減に影響を及ぼす要因

影響要因	全体	大企業	中堅企業	中小企業	ベンチャー・ INNO-BIZ企業
研究開発投資の増減による研究成果の変化	10.3%	8.9%	14.3%	9.3%	11.1%

企業の事業戦略の変化(事業分野の多角化または事業構造調整など)	11.4%	12.9%	13.0%	9.6%	13.4%
企業の産業財産権戦略の変化(量または品質中心の知的財産出願戦略、維持費用対比収益性戦略の変化など)	10.4%	17.2%	16.8%	8.0%	11.4%
市場及び技術競争環境の変化(市場の拡大または縮小、新技術または新市場の出現など)	12.8%	10.0%	12.0%	10.7%	16.5%
国内及びグローバル景気の変動(国内総生産の増減、物価及び為替の変化、世界金融危など機)	7.1%	3.9%	4.6%	6.9%	8.5%
産業財産権出願環境の改善及び支援制度の強化(出願手数料の減免、手続きの簡素化、知財権創出支援制度など)	10.6%	3.8%	15.0%	10.5%	11.0%

注. (%)は[(優先順位が最も高いと回答した機関数)/(総回答機関数)]×100(%)

一方、知的財産権出願の増減に最も大きな影響を及ぼす要因として全体企業の12.8%(15.5%)、11.4%(13.6%)が企業外部の環境的要因である「市場及び技術競争環境の変化」と内部的な要因である「企業の事業戦略の変化」を挙げた。

企業類型別では、大企業と中堅企業の場合「企業の産業財産権戦略の変化」が知的財産権の出願に影響を及ぼすと答えた比率が最も高く、一般中小企業とベンチャー企業の場合は「市場及び技術競争環境の変化」に大きな影響を受けると答えた比率が相対的に高い([表 2.13])。

#### 4. 産業財産権の出願/審査/維持費用及び関連規定の状況

2013年の1年間知的財産権の国内及び海外出願・審査・維持のために企業が支出した平均金額は1億126万ウォン(1億853万ウォン)となっている([表 2.14])。企業類

型別では、大企業、中堅企業、一般中小企業、ベンチャー/INNO-BIZ 企業の平均支出額は其々6億623万ウォン(9億920万ウォン)、9,946万ウォン(9,768万ウォン)、4,206万ウォン(4,791万ウォン)、4,004万ウォン(4,414万ウォン)となっている。国内出願・審査費用対維持費用の比率は一般中小企業と大企業の場合59.9%(56.7%)、58.5%(59.2%)で高く、一方海外出願・審査費用対維持費用の比率は逆にベンチャー企業と中堅企業が52.9%(54.6%)、48.2%(46.6%)で高い。

[表 2.14] 知的財産の出願・審査・維持費用

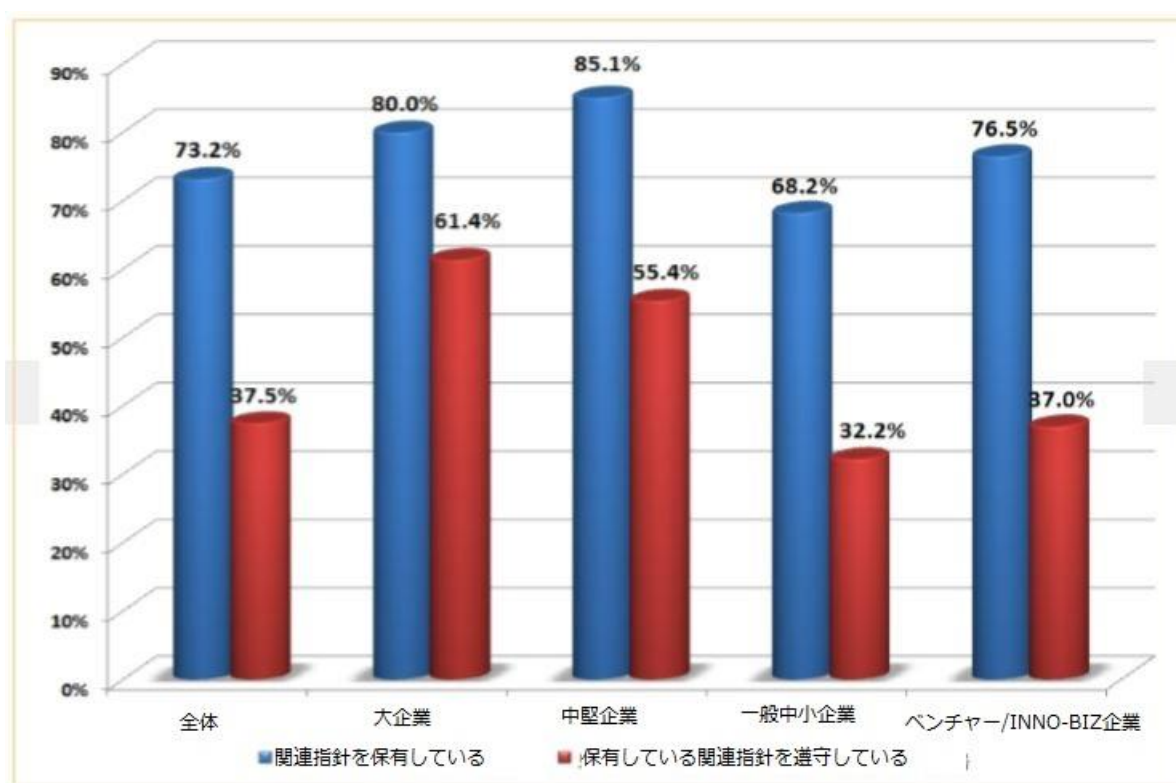
	国内		海外		出願・審査・維持費用の合計
	出願・審査 <sup>36</sup>	維持 <sup>37</sup>	出願・審査	維持	
全体	2,009 万ウォン	1,133 万ウォン	5,595 万ウォン	1,389 万ウォン	1億 126万ウォン
大企業	1億2,795 万ウォン	7,486 万ウォン	3億4,308 万ウォン	6,034 万ウォン	6億 623万ウォン
中堅企業	3,287 万ウォン	1,328 万ウォン	3,596 万ウォン	1,734 万ウォン	9,946 万ウォン
一般中小企業	1,323 万ウォン	793万ウォン	1,464 万ウォン	626 万ウォン	4,206万ウォン
ベンチャー /INNO-BIZ 企業	1,093 万ウォン	519万ウォン	1,565 万ウォン	827 万ウォン	4,004万ウォン

全体企業の73.2%(79.2%)に該当する企業は営業秘密の管理及び技術流出防止指針を保有しているが、但し37.5%(42.9%)がこれを遵守していることがわかった([図2.40])。より詳しく見ると、全体企業の35.7%(36.3%)は関連指針は保有しているものの遵守しなければならないという認識が低く、26.8%(20.8%)は関連指針を保有していないことが分かった。

<sup>36</sup> 出願/審査費用は産業財産権の出願手数料、審査請求料、弁理士費用、決定系審判(特許出願に対する拒絶決定など審査官の処分不服して請求する審判)にかかった費用

<sup>37</sup> 維持費用は産業財産権の登録と権利維持にかかる金額(登録料と維持年金)

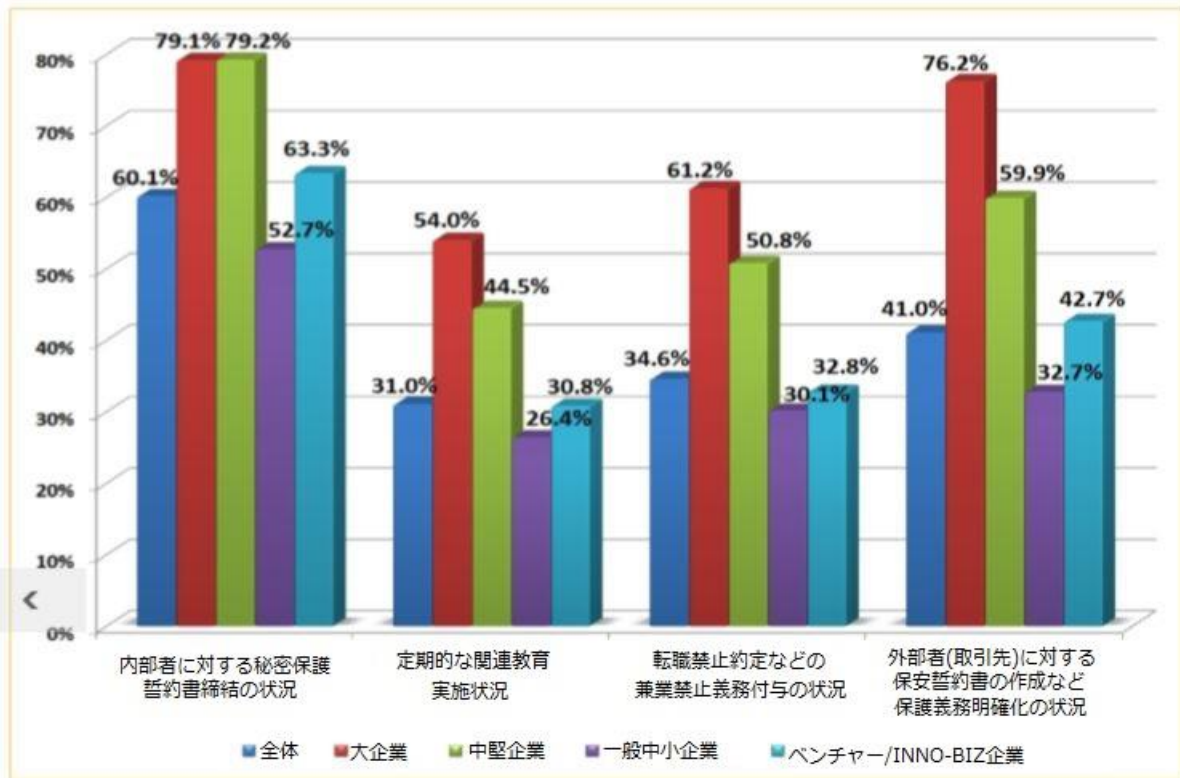
企業類型別では中堅企業の 85.1% (89.2%) が関連指針を保有していると答えて最も高く、大企業の場合 80.0% (88.4%) が関連指針を保有していると答えた。しかし、関連指針を遵守している比率の場合、大企業の 61.4% (63.9%) が遵守すると答えて最も高く、中堅企業が 55.4% (61.9%) と続いている。ベンチャー企業の場合関連指針を保有して遵守する比率は其々 76.5% (77.7%)、37.0% (38.5%)、一般中小企業は 68.2% (77.3%) と 32.2% (40.2%) と相対的に低い。



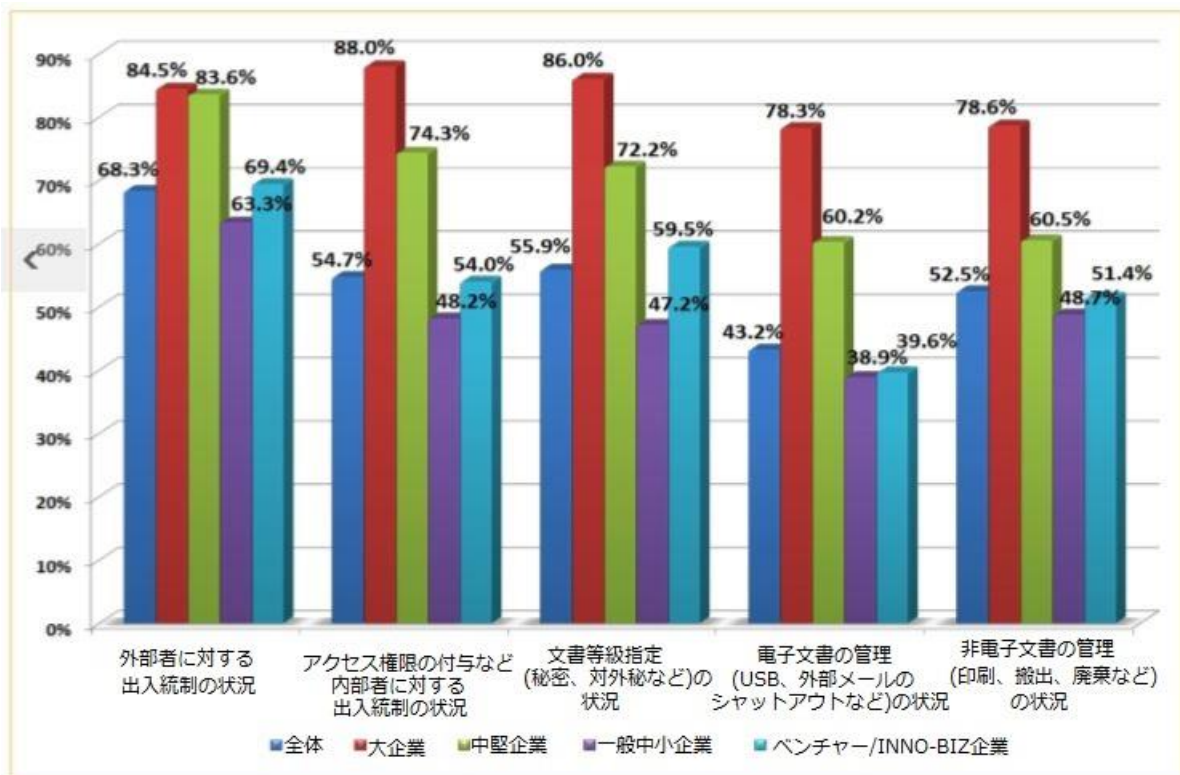
[図 2.40] 営業秘密の管理及び技術流出防止指針の保有・遵守状況

営業秘密の管理及び技術流出防止に向けた人的、物的管理の状況は以下の [図 2.41]、[図 2.42] のとおりである。





[図 2.41] 営業秘密管理及び技術流出のための人的管理状況



[図 2.42] 営業秘密管理及び技術流出防止のための物的管理状況

## 5. 効果的な知的財産保護のために必要な政策支援

知的財産を効果的に保護するため「産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免」が必要であると答えた比率は 65.2%と最も高く、「知的財産侵害に対する強力な処罰基準の制定」、「海外出願関連情報の提供」、「知的財産侵害に対するコンサルティング支援と共同取締」が必要であると答えた比率は其々 61.6% (61.8%)、57.5% (58.4%)、56.4% (57.8%)となっている([表 2.15])。

企業類型別では「産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免」が必要であると答えた比率は一般中小企業を除く全ての企業類型において最も高く、特にベンチャー企業及び中堅企業が其々 74.4% (74.3%)、74.0% (74.8%)と高い。一般中小企業の場合は「知的財産権侵害に対する強力な処罰基準の制定」の必要性が 58.6% (56.6%)と最も高い。

[表 2.15] 効果的な知的財産保護のための政策支援の必要性

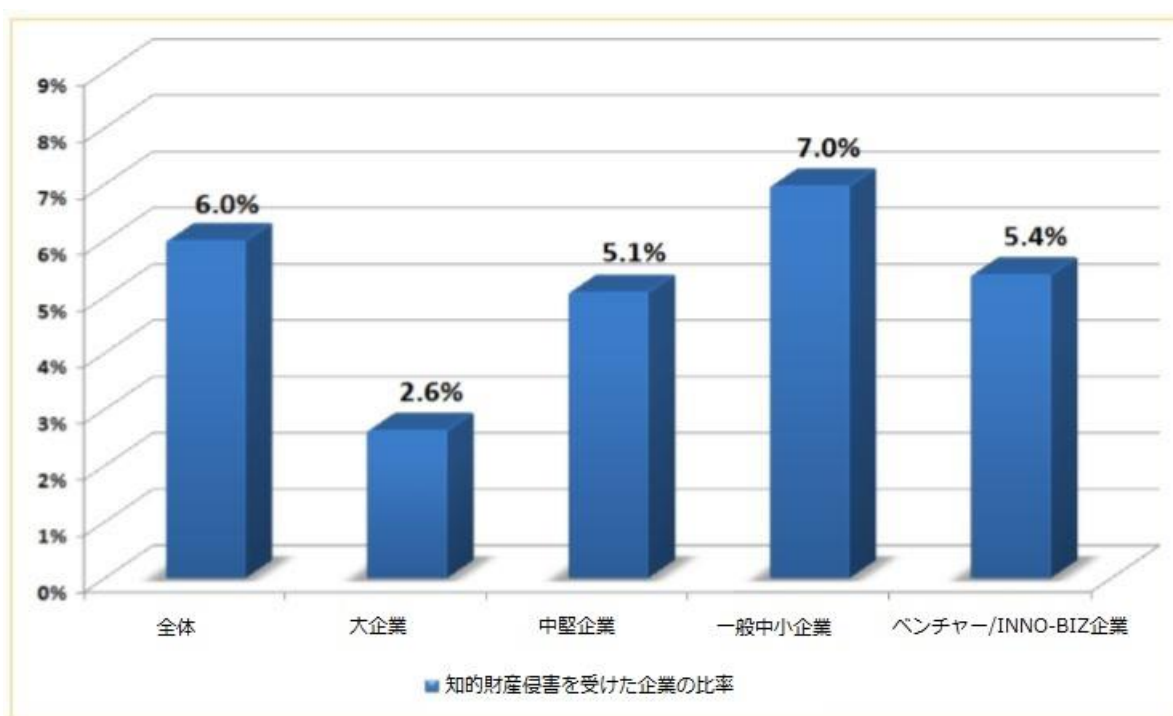
	全体	大企業	中堅企業	一般中小企業	ベンチャー・ INNO-BIZ 企業
産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免	65.2%	69.8%	74.0%	57.0%	74.4%
海外出願関連情報の提供	57.5%	57.7%	66.5%	54.6%	59.6%
知的財産権侵害に対する強力な処罰基準の制定	61.6%	69.6%	64.3%	58.6%	63.8%
知的財産権害に対するコンサルティング支援と共同取締	56.4%	63.1%	58.7%	53.1%	59.4%

注. (%)は 5 点尺度(1: 必要性が最も低い、5: 必要性が最も高い)で[(4 点と 5 点と答えた企業数)/(総回答機関数)]×100(%)

## 第5節 知的財産の侵害及び紛争

### 1. 知的財産権侵害及び被害規模

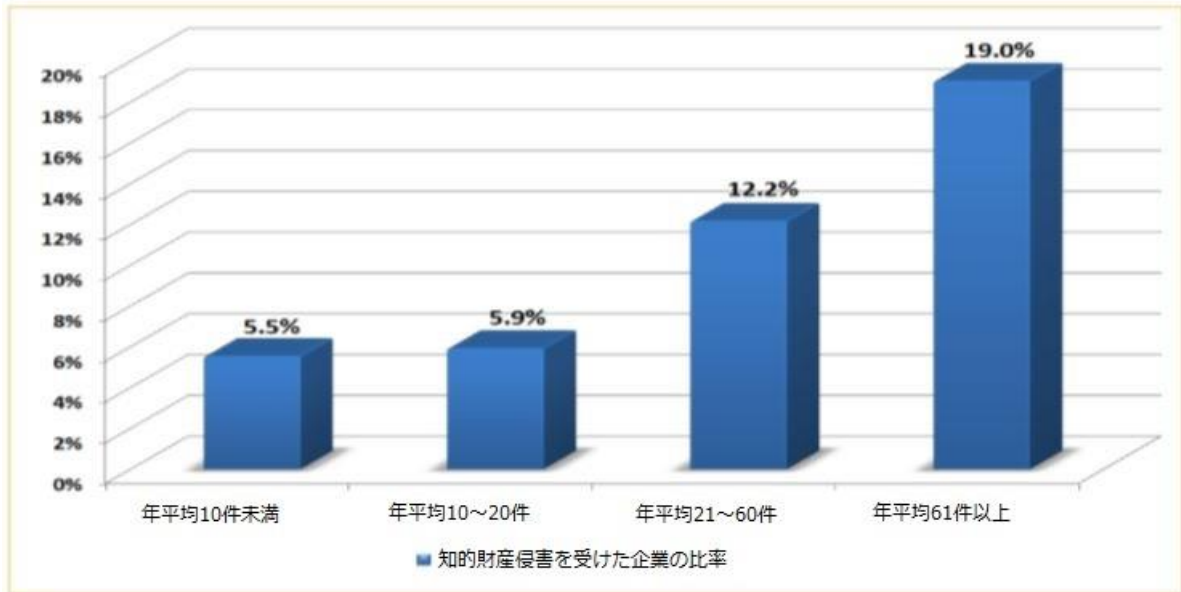
2013年に1件以上の知的財産権<sup>38</sup>侵害を受けた企業は全体の6.0%を占めている。企業類型別では一般中小企業が7.0%、ベンチャー企業が5.4%、中堅企業5.1%、大企業の2.6%が知的財産権侵害を受けたことがわかった([図 2.43])。



[図 2.43] 企業類型別の知的財産権侵害の被害比率

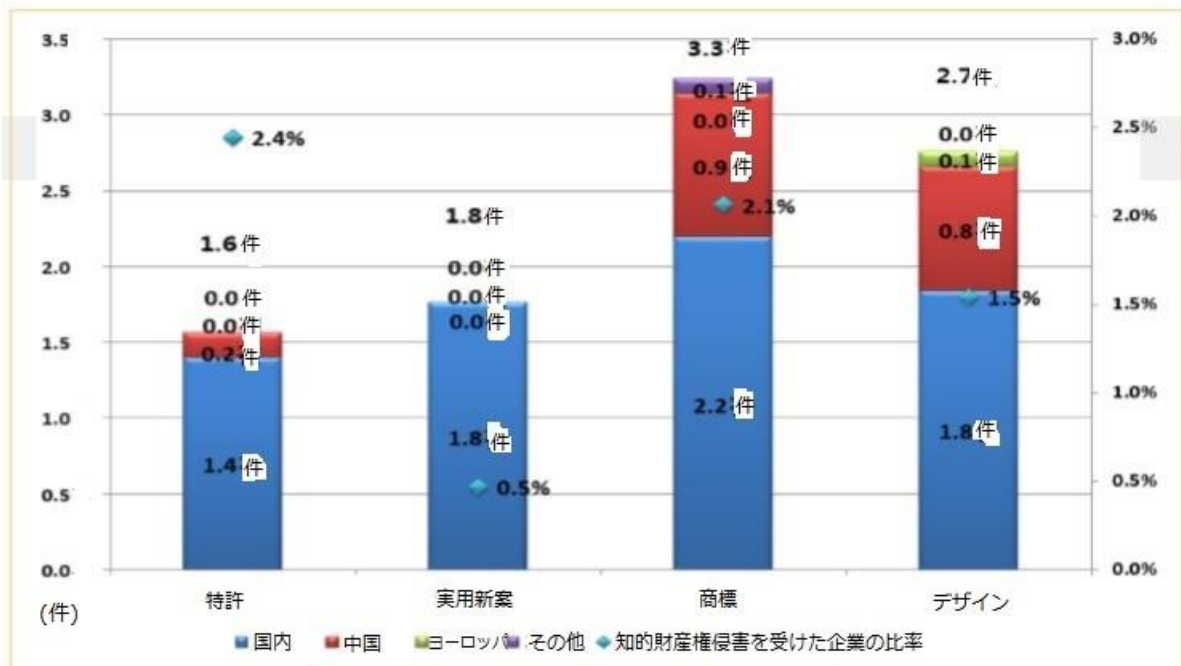
産業財産権の出願規模で見ると、年平均10件未満を出願する企業は5.5%である一方、年平均10～20件を出願する企業の場合知的財産権侵害を受けた企業が5.9%、年平均21～60件を出願する企業のうち知的財産権侵害を受けた企業は12.2%、61件以上を出願した多出願企業の比率は19.0%であることが分かった([図 2.44])。

<sup>38</sup> 産業財産権(特許、実用新案、商標、デザイン)及び新知的財産権(半導体配置設計、地理的表示、営業秘密など)が含まれる。



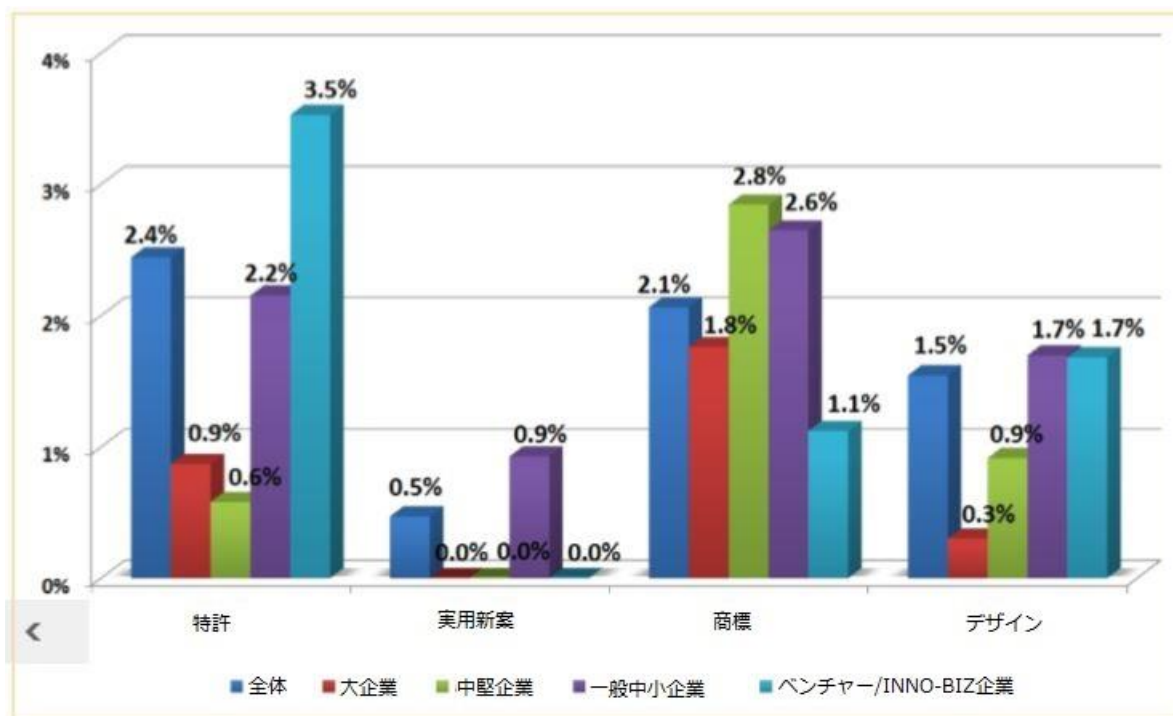
[図 2.44] 出願件数別の知的財産権侵害の被害比率

産業財産権類型別に侵害被害を受けた企業の比重及びこれらの平均被害件数は[図 2.45]のとおりである。2013 年の 1 年間特許権侵害を受けた企業は全体の 2.4%で最も高く、その他に商標、デザイン、実用新案権の侵害を受けた企業の比率は其々 2.1%、1.5%、0.5%となっている。其々の平均侵害件数は特許が 1.6 件、実用新案 1.8 件、商標が 3.3 件、デザインが 2.7 件となっている。



[図 2.45] 産業財産権類型別の侵害被害件数

企業類型別では特許権の侵害を受けたベンチャー企業は 3.5%、中小企業は 2.2%、大企業は 0.9%、中堅企業は 0.6%で、他企業類型に比べてベンチャー企業及び一般中小企業の比率が高いことがわかる([図 2.46])。特に、ベンチャー企業の場合、技術を基盤とする企業の特徴が反映されたものと見られる。



[図 2.46] 企業類型別の産業財産権侵害の被害比率

出願規模別では、10 件未満の場合 2.3%、10 件～20 件である企業の場合が 2.2%、21 件～60 件である企業の場合が 4.7%、61 件以上の多出願企業の場合 5.5%であり、多出願企業の特許侵害被害比率が比較的に高いことがわかる([表 2.16])。

[表 2.16] 出願規模別の特許侵害比率

	年平均 10 件未満	年平均 10～20 件	年平均 21～60 件	年平均 61 件以上
特許権 侵害比率	2.3%	2.2%	4.7%	5.5%

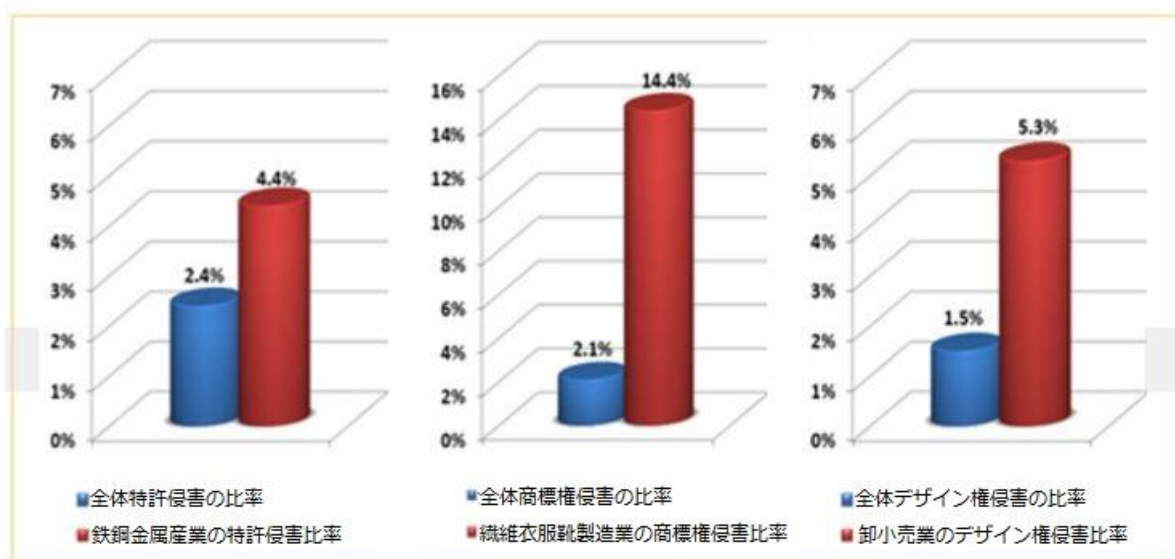
商標権の場合、中堅企業が 2.8%、一般中小企業 2.6%、大企業が 1.8%、ベンチャー企業 1.1%である。出願規模別の侵害被害比率を見ると、多出願企業であるほど被害比率が高いことがわかる。

[表 2.17] 出願規模別の商標権侵害比率

	年平均 10 件未満	年平均 10～20 件	年平均 21～60 件	年平均 61 件以上
商標権侵害比率	1.7%	3.4%	6.6%	7.5%

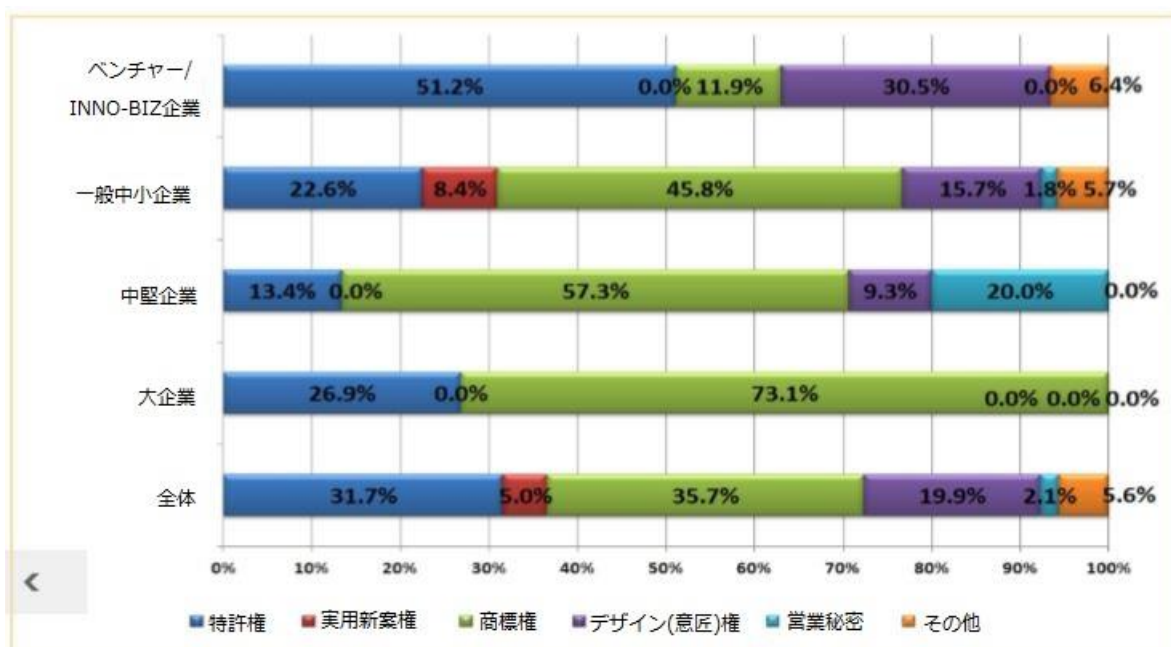
特許権の他に実用新案権の侵害を受けた比率は一般中小企業が 0.9%で最も高く、デザイン権の侵害を受けた比率は一般中小企業とベンチャー企業が其々 1.7%、1.7%で最も高い。

各権利による業種別侵害比率の特徴を見ると、次の[図 2.47]のとおりである。特許侵害比率の場合鉄鋼/金属産業が 4.4%で全体特許侵害比率の 2.4%に比べて高いことが分かった。また、商標権侵害比率の場合全体 2.1%に比べて繊維/衣服/靴の製造業が 14.4%と高く、デザイン権の場合卸・小売業の侵害比率が 5.3%で全体 1.5%に比べて高く、業種別の特徴が反映されている。



[図 2.47] 各権利別業種による侵害比率の特徴

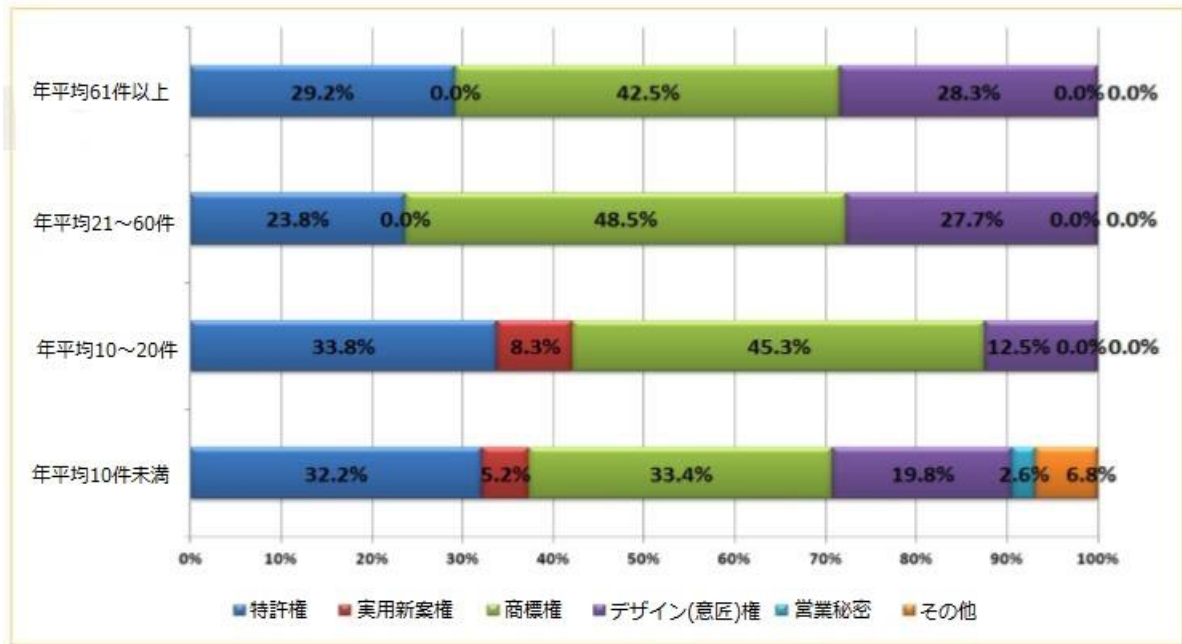
次の[図 2.48]は知的財産権侵害被害における具体的な内容から権利類型の分布を示している。全体侵害事例の中で商標権が占める比重は 35.7%で最も高い。また、特許権 31.7%、デザイン権 19.9%、実用新案権 5.0%、営業秘密侵害 2.1%と続いている。



[図 2.48] 権利類型別の被害状況

企業類型別では大企業と中堅企業、一般中小企業の場合全体侵害事例のうち商標権侵害が其々73.1%、57.3%、45.8%と最も高い。一方、ベンチャー企業の場合は全体侵害事例のうち 51.2%が特許権侵害で他の権利類型より高いことが分かった。



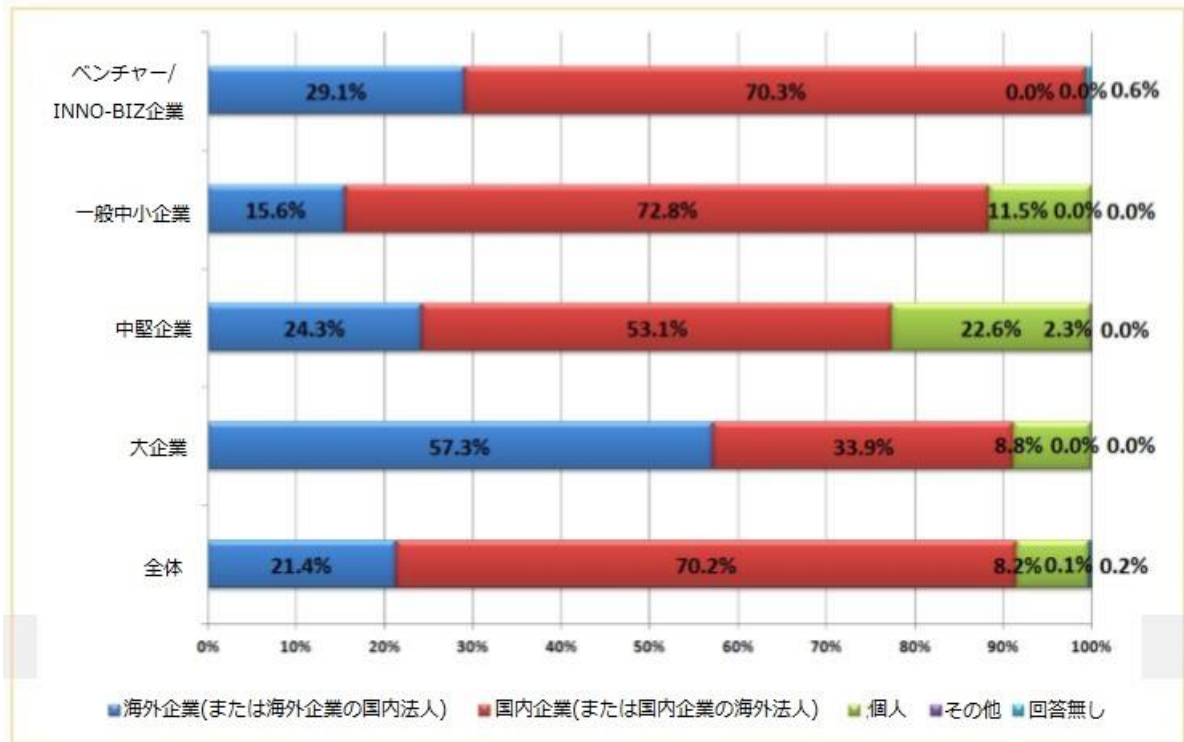


[図 2.49] 産業財産権出願規模別の全体侵害事例のうち特許権侵害の比重

産業財産権の出願規模別で見ると、年平均 10 件～20 件出願した企業の場合は特許権の侵害比重が 33.8% で最も高い([図 2.49])。

知的財産権侵害被害の具体的な内容の中で侵害製品製造者の分布は[図 2.50]のとおりである。全体被害事例のうち 70.2% は国内企業、21.4% は海外企業であることが分かった。また、個人の場合も全体の 8.2% となっている。中堅企業、一般中小企業、ベンチャー企業はいずれも侵害事例のうち侵害製品製造者が国内企業である比率が其々 53.1%、72.8%、70.3% と製造者が海外企業または個人である場合に比べて高い。一方、大企業は海外企業である場合が 57.3% と相対的に高い。

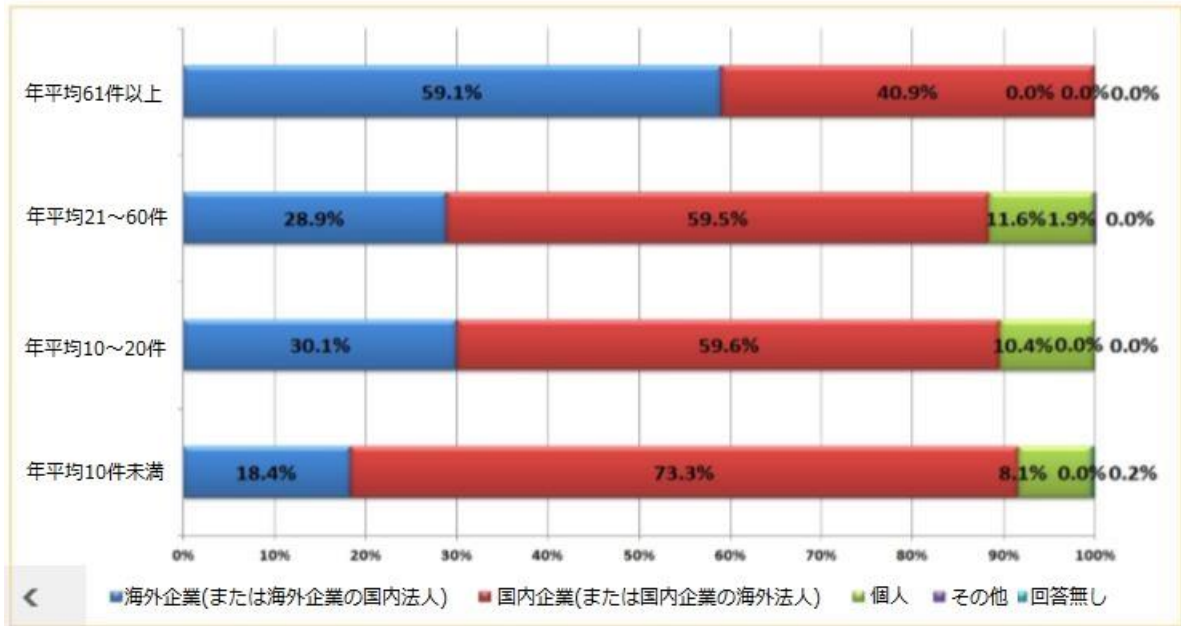




[図 2.50] 侵害製品製造者別の被害状況

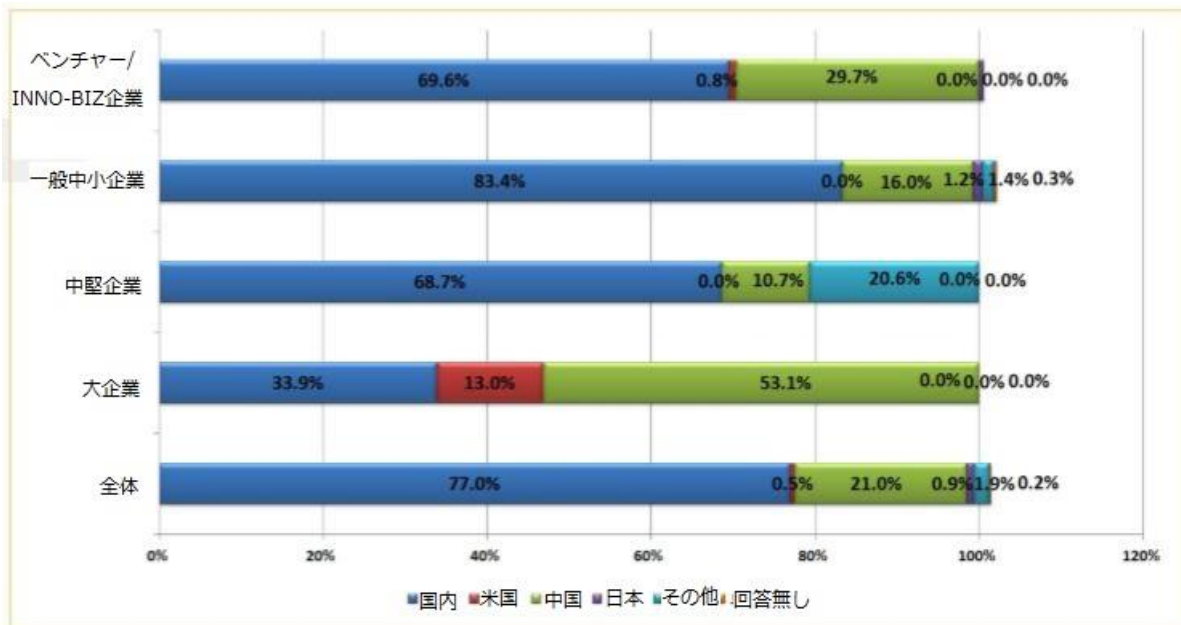
注：複数回答

産業財産権の出願規模別で見ると、侵害製品製造者が国内企業である比率は年平均10件未満企業の場合極めて高い数値となっている。一方、年平均61件以上の多出願企業の場合侵害製品製造者が海外企業である比率が高いことが分かった。



[図 2.51] 産業財産権出願規模別の侵害製品製造者の類型別比率

侵害被害の具体的な内容のうち侵害製品製造地域の分布は[図 2.52]のとおりである。侵害製品製造地域が国内である場合は全体の 77.0%で最も高い。また、製造地域が中国である場合が 21.0%と続いている。

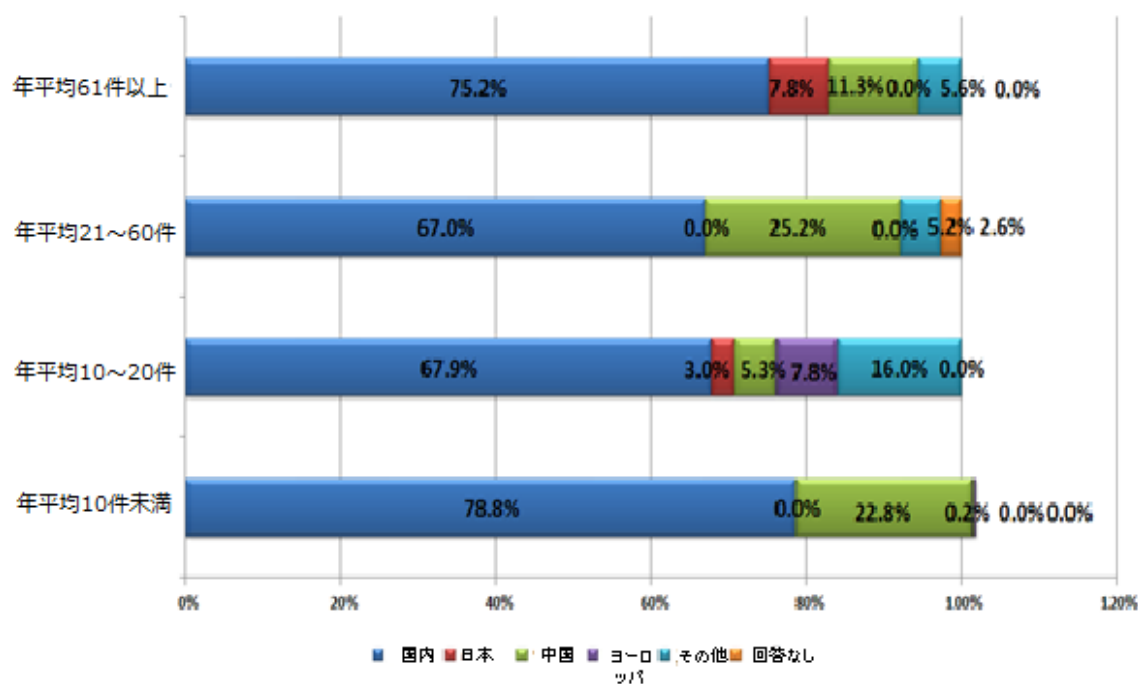


[図 2.52] 侵害製品製造地域別の被害状況

注. 複数回答

特に大企業の場合製造地域が中国の場合が 53.1%と極めて高く、大企業以外の他企業類型の場合は全体被害状況と同じく国内侵害被害比率が最も高いことが分かる。侵害製品製造地域が国内である比重が最も高い場合は一般中小企業で、全体の 83.4%を占めている。

産業財産権の出願規模別で見ると、侵害製品の製造地域が国内である比重が年平均 10 件未満企業の場合 78.8%で最も高く、年平均 10～20 件出願規模の企業の場合 67.9%、年平均 21～60 件の場合は 67.0%となっている。中国が侵害製品の製造地域である場合は年平均 21～60 件未満の場合 25.2%で最も高いことが分かった。

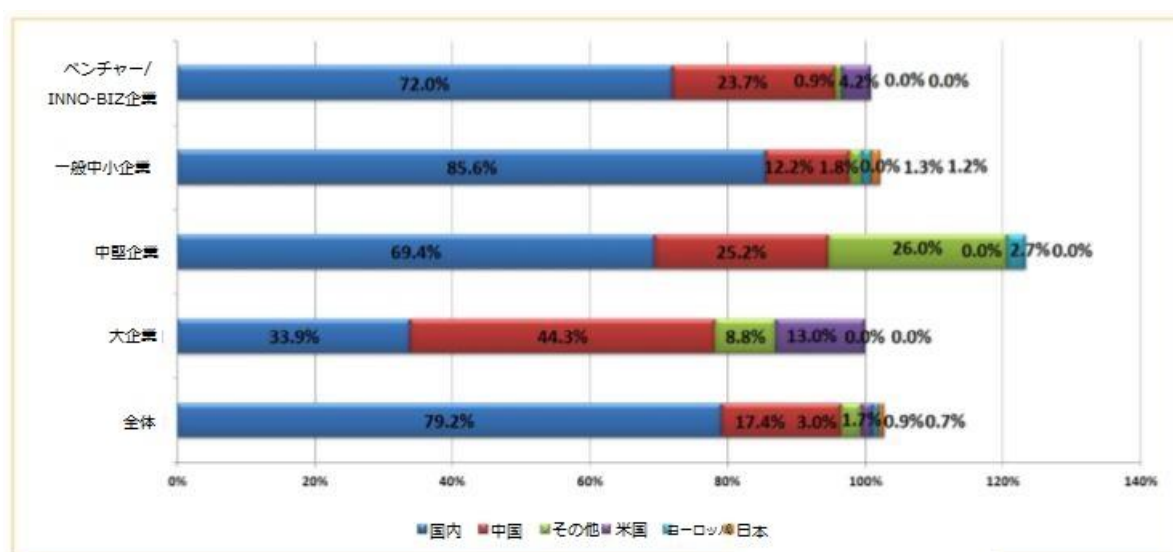


[図 2.53] 産業財産権出願規模別の侵害製品製造地域の比率

注：複数回答

知的財産権侵害被害の具体的な内容のうち侵害製品の流通地域の分布は[図 2.54]のとおりである。全体被害事例のうち 79.2%は侵害製品の流通地域が国内であり、流通地域が中国である比重も 17.4%となっている。企業類型別では、流通地域が国内である比重は一般中小企業が 85.6%で他企業類型に比べて高く、大企業は 33.9%で最も

低い。大企業の場合中国で侵害製品が流通する場合が 44.3%で最も高く、大企業を除く全ての企業類型において侵害製品は国内で多く流通していることが分かる。海外で侵害製品が流通する場合は大企業と一般中小企業、ベンチャー企業、いずれも中国で流通する比率が比較的が高い。このように中国における侵害事例が増加している状況の中で企業は警告書を発送するなど対応に取り組んでいるが、まだ実効性の側面では難航しているものと見られる。

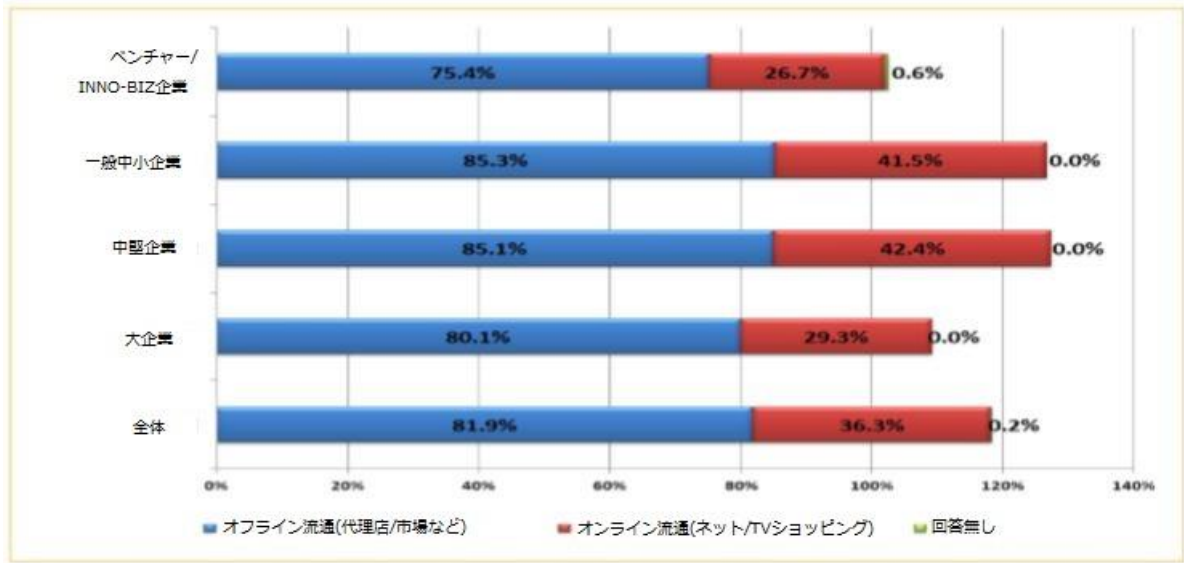


[図 2.54] 侵害製品流通地域別の被害状況

注. 複数回答

産業財産権の出願件数による規模別に見ると、侵害製品の流通地域が国内である場合は年平均 10 件未満規模の企業の場合が最も高い 82.4%となっており、年平均 61 件以上の多出願企業の場合はむしろ低い 61.0%となっている。流通地域が中国である比重は年平均 61 件以上の多出願企業の場合 27.0%で最も高い。

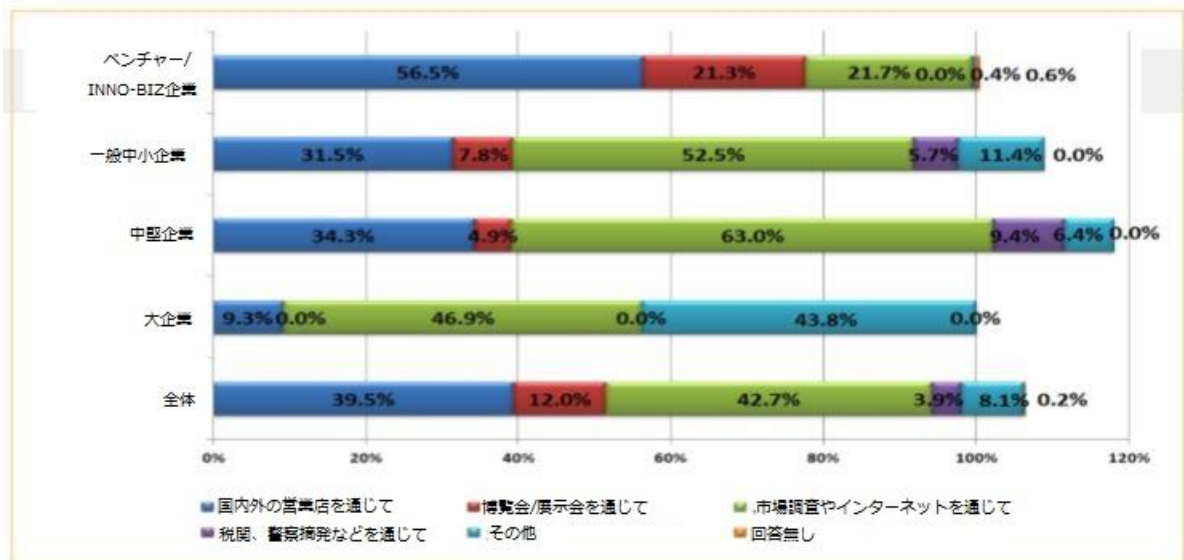
知的財産権侵害被害の具体的な内容のうち侵害製品流通タイプの分布は[図 2.55]のとおりである。全体被害事例の 81.9%は代理店及び市場などオフラインで流通するものと見られる。インターネット及び通販などオンラインで流通する比率は中堅企業が 42.4%で他企業類型より高い。



[図 2.55] 侵害製品の流通類型及び被害状況

注. 複数回答

知的財産権侵害被害の具体的な内容のうち侵害製品発見経路の分布は[図 2.56]のとおりである。全体被害事例のうち 42.7%の場合市場調査やインターネットを通じて、39.5%の場合は国内外の営業店を通じて被害事実を認知していることが分かった。企業類型別では、ベンチャー企業の除いて全ての企業が市場調査やインターネットを通じて被害事実を認知する比率が最も高い。ベンチャー企業の場合国内外の営業店を通じて被害事実を認知する比率が 56.5%で最も高い。

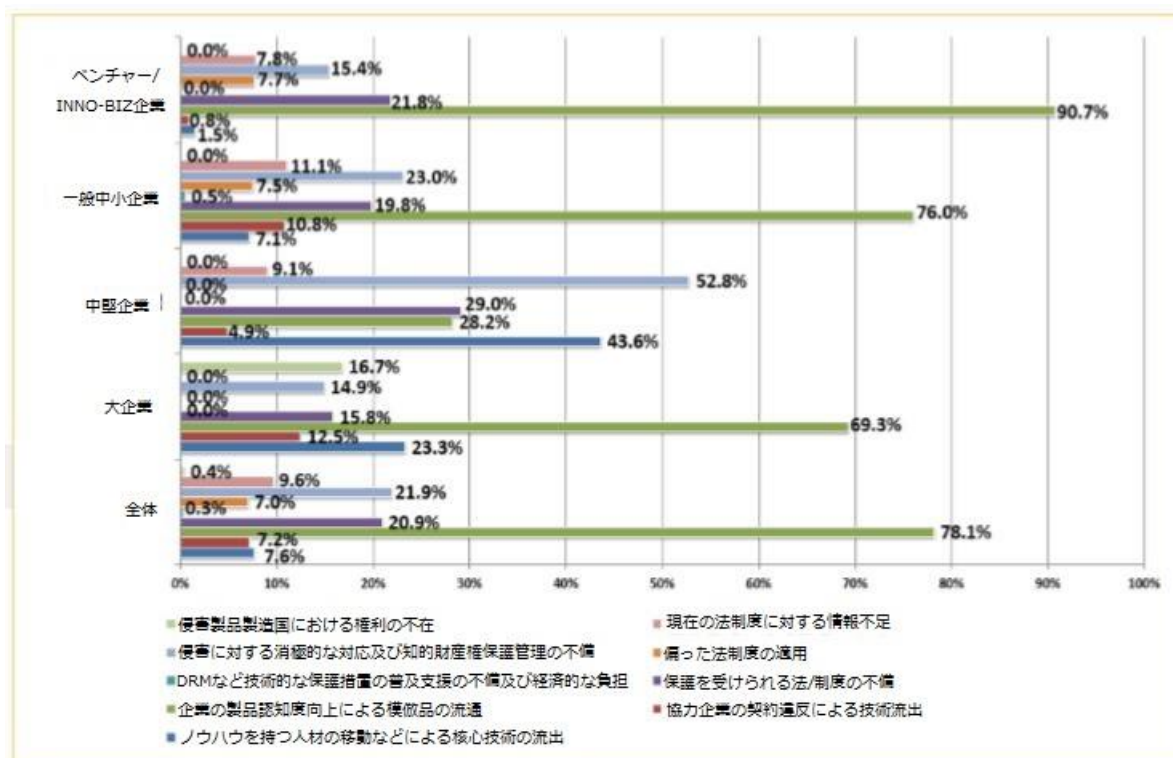


[図 2.56] 侵害製品発見経路別の被害状況

注. 複数回答

知的財産権侵害による被害が発生した原因は[図 2.57]のとおりである。「企業製品の認知度向上による模倣品の流通」を原因として挙げた企業の比率は知的財産権侵害を受けた企業のうち 78.1%と、全ての企業類型において最も高いことが分かった。また、「侵害に対する消極的な対応及び知的財産権の保護・管理の不足」、「保護を受けられる法/制度の不備」を挙げた企業の比率は其々 21.9%、20.9%と続いている。

企業類型別では「企業製品の認知度向上による模倣品の流通」を原因として挙げた比率を除けば、大企業の場合「ノウハウを持つ人材の移動などによる核心技術の流出」が 23.3%で二番目に高い比重を占めている。また、一般中小企業の場合「侵害に対する消極的な対応及び知的財産権の保護・管理の不足」、ベンチャー企業の場合は「保護を受けられる法/制度の不備」が二番目に高い比重を占めた理由となっている。

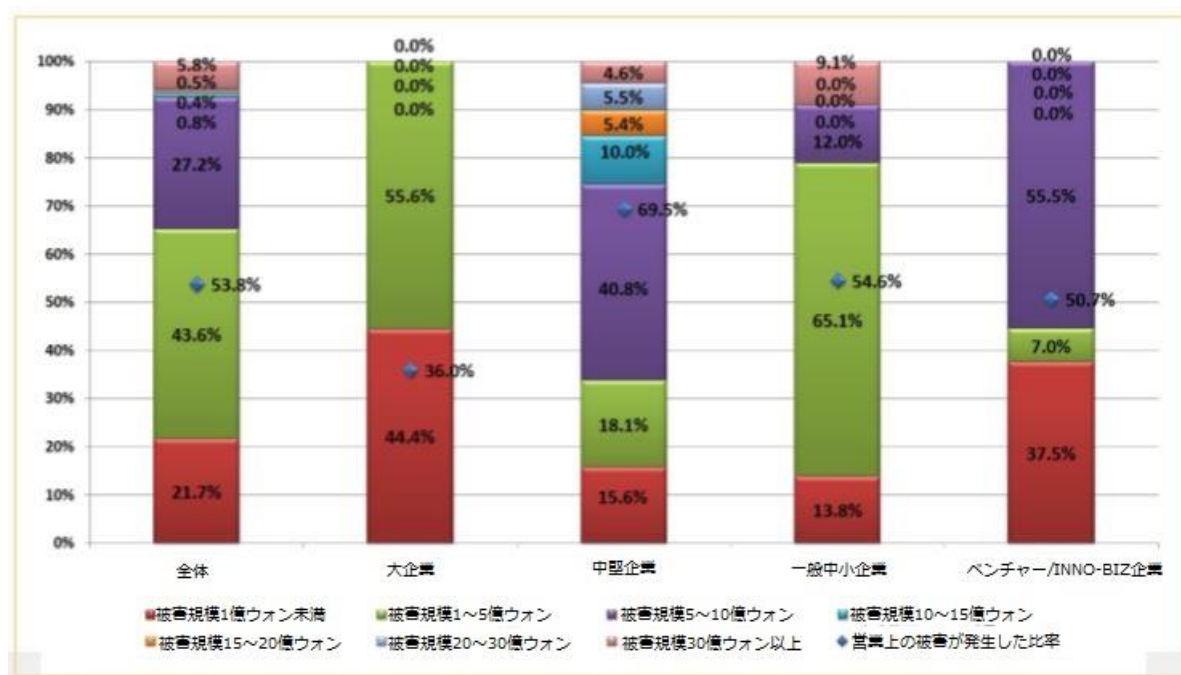


[図 2.57] 知的財産権侵害の被害が発生した主な原因

注. 複数回答



侵害製品が市場に流出したことで売上の減少や市場シェアの下落のような営業上の被害が実際に発生した比率は知的財産権の侵害を受けた企業のうち 53.8%を占めた（[図 2.58]）。企業類型別で見ると、中堅企業が 69.5%で最も高く、一般中小企業が 54.6%、ベンチャー企業が 50.7%と比較的に高い。一方、大企業は 36.0%で最も低いことが分かった。



[図 2.58] 実際被害金額の規模

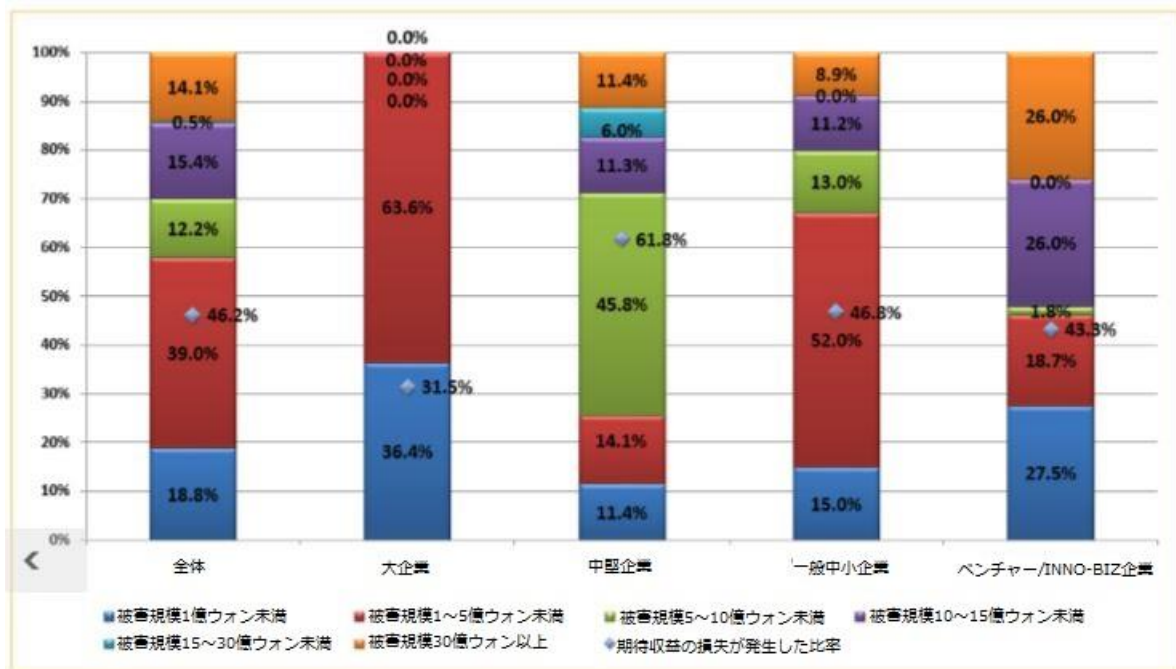
このような営業上の被害、即ち実際発生した被害金額の規模は 1～5 億ウォン未満が全体の 43.6%で最も高い比重を占め、30 億ウォン以上の場合も 5.8%を占めている。特に、一般中小企業の場合 30 億ウォン以上の場合が 9.1%で中堅企業 4.6%、ベンチャー企業 0.0%に比べて高い。企業類型別では、一般中小企業は 5～10 億ウォン未満の場合が 65.1%で最も高く、ベンチャー企業は 1～5 億ウォン未満の場合が 55.5%で最も高い。

産業財産権の出願規模による結果を見ると、年平均 21～60 件出願企業の被害金額発生比率は 68.1%で最も高い（[表 2.18]）。年平均 10 件未満企業の場合 54.4%、10～20 件企業の場合 47.4%、61 件以上多出願企業の場合 29.7%となっている。

[表 2.18]産業財産権出願規模別の実際被害金額が発生した企業の比率

	年平均 10 件未満	年平均 10～20 件	年平均 21～60 件	年平均 61 件以上
実際被害金額が発生した比率	54.4%	47.4%	68.1%	29.7%

一方、売上高の減少など実質的な営業上の被害はなかったものの今後の新規市場への参入、技術移転などを通じて得られるはずであった期待収益の損失が予想されると答えた場合は知的財産権侵害被害企業の 46.2%となっている（[図 2.59]）。このような比率は企業類型別で見ると中堅企業が 61.8%で最も高い。



[図 2.59]未実現被害金額の規模

企業が認知している未実現被害金額の規模は 1～5 億ウォン未満が 39.0%で最も大きな比重を占めているが、これは特に大企業での比重が 63.6%と高く、一般中小企業の場合も 52.0%と高い方である。



産業財産権の出願規模で見ると、年平均 10 件未満企業の場合は 47.1%であるが、10～20 件企業の場合 54.7%、21～60 件規模の企業の場合 32.8%、61 件以上の多出願企業の場合 32.7%で、多出願企業が最も低い。

[表 2.19]産業財産権出願規模別の未実現金額発生企業の比率

	年平均 10 件未満	年平均 10～20 件	年平均 21～60 件	年平均 61 件以上
未実現被害金額の発生比率	47.1%	54.7%	32.8%	32.7%

2013 年の 1 年間全体被害発生規模を推定した結果は以下の[表 2.20]のとおりである。実際発生した被害金額(営業上の被害金額)及び未実現被害金額(期待収益の損失金)は其々4,529 億ウォン、5,811 億ウォンであり、被害企業の平均金額は其々6 億 8 千万ウォン、10 億 2 千万ウォンである。

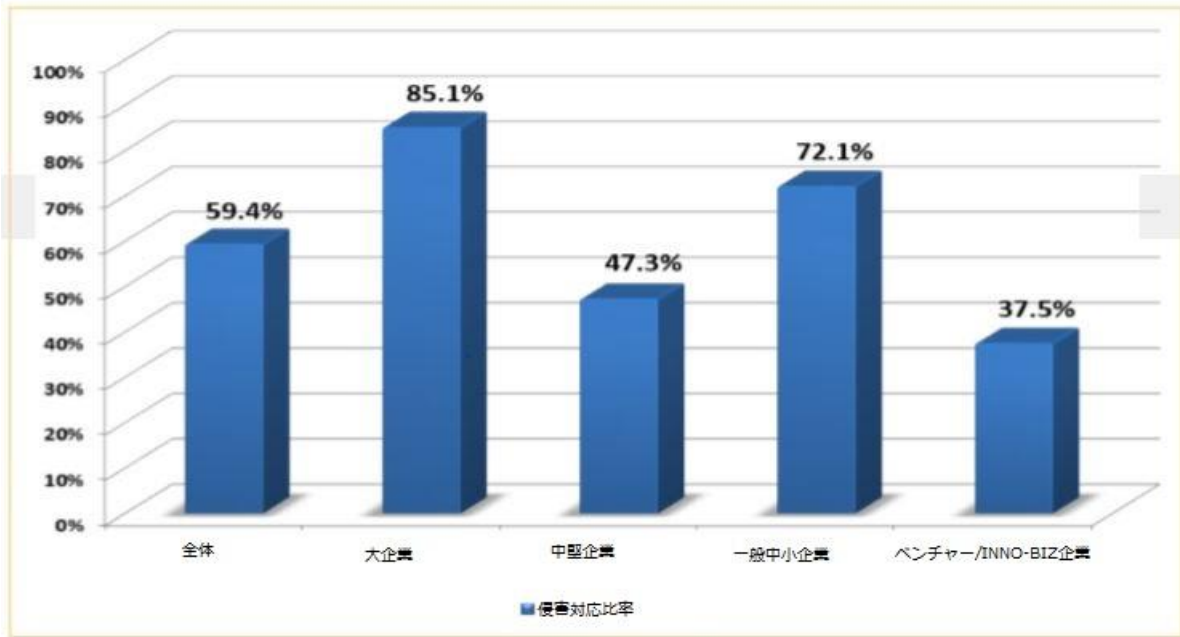
[表 2.20]全体侵害被害規模の推定

区分	企業数 <sup>39</sup>	被害金額(2013 年)(億ウォン)	
		合計	被害企業の平均
実際発生した被害金額(営業上の被害金額)	665	4,529	6.8
未実現被害金額(期待収益の損失金)	571	5,811	10.2

## 2. 知的財産権侵害に対する対応状況

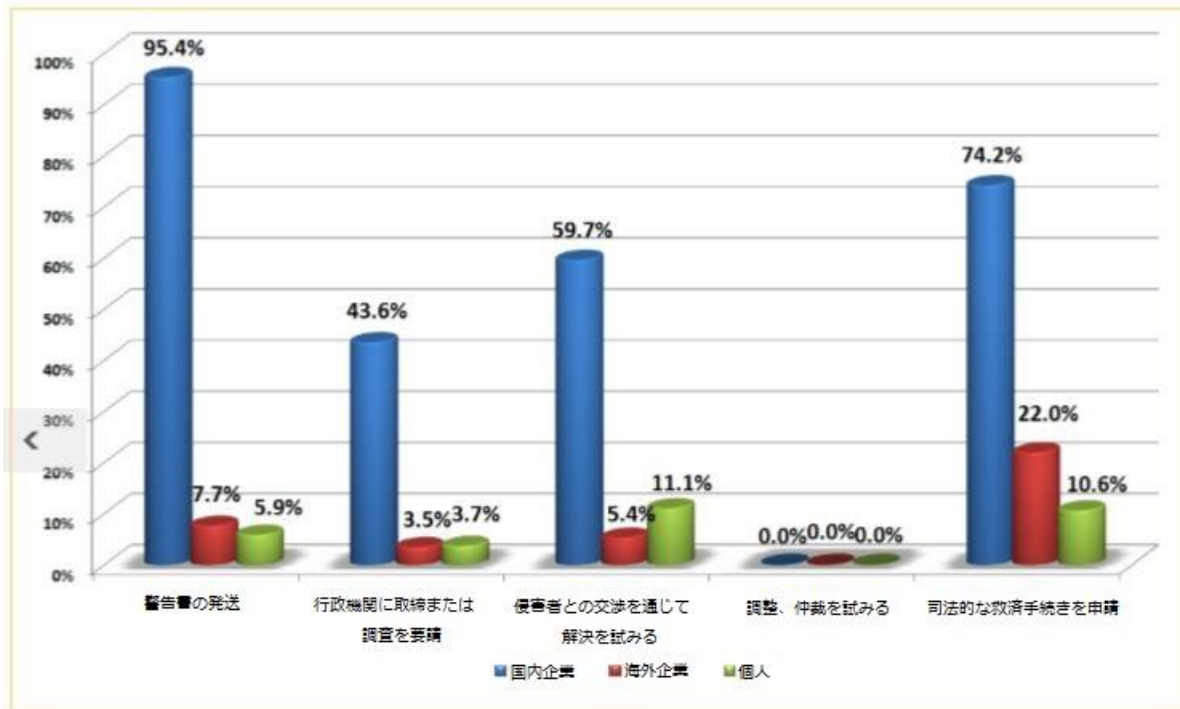
知的財産権の侵害被害経験がある企業が侵害被害に対応した場合は 59.4%である。大企業の場合が 85.1%で最も高く、一般中小企業の場合 72.1%、中堅企業が 47.3%、ベンチャー企業が 37.5%となっている([図 2.60])。

<sup>39</sup> 母集団の推定値である。



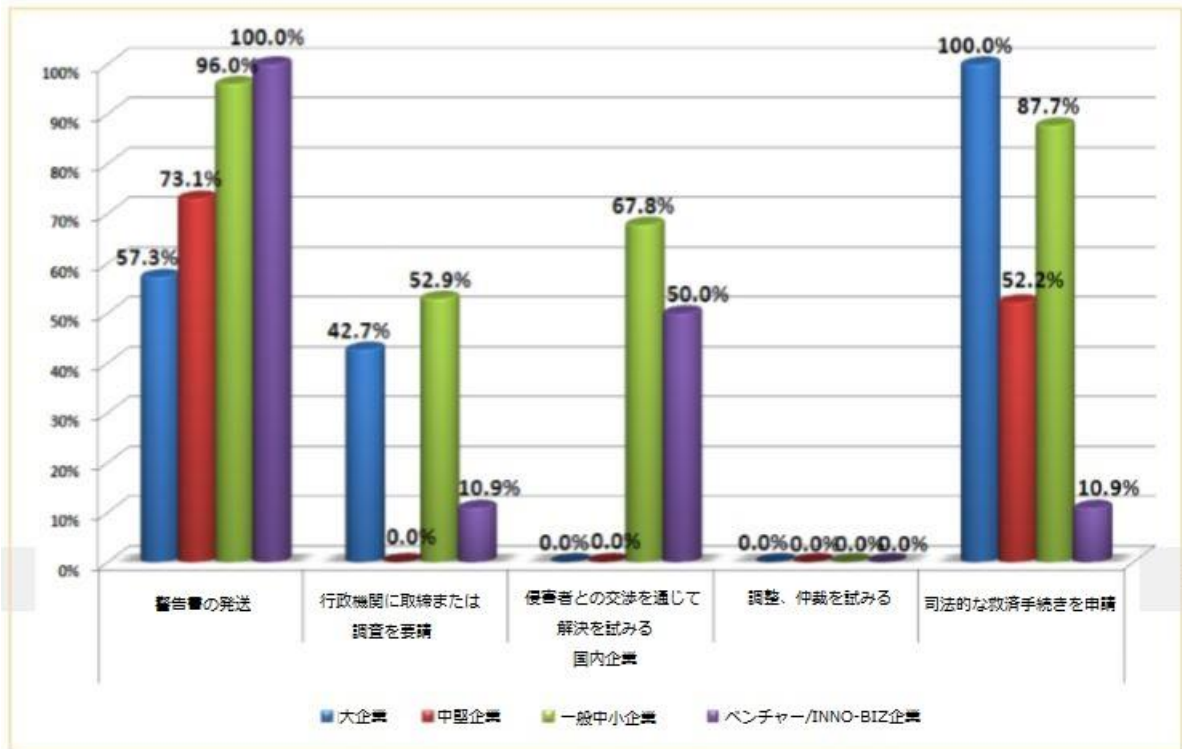
[図 2.60] 知的財産権侵害への対応比率

知的財産権侵害被害への対応活動として国内企業に警告書を発送した場合は知的財産権侵害を受けた企業のうち 95.4%と最も多い比重を占め、司法的な救済手続きを申請した場合は 74.2%、侵害者との交渉を通じて解決を試みる場合は 59.7%、行政機関に取締または調査を要請した場合は 43.6%と続いている([図 2.61])。知的財産権を侵害した海外企業に対する対応活動として司法的な救済手続きを申請する場合は知的財産権侵害を受けた企業の 22.0%と最も多い比重を占めた。



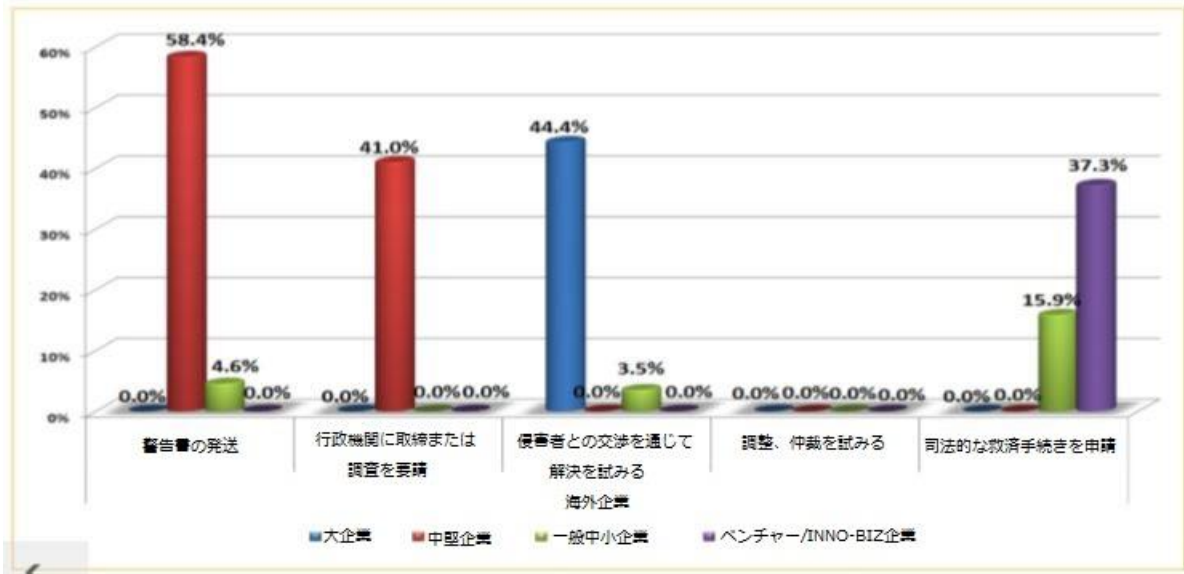
[図 2.61] 知的財産権侵害における対象別の対応法

企業類型別で見ると、知的財産権侵害を受けた企業のうち国内企業に警告書を発送した比率は大企業が 57.3%と最も低い、ベンチャー企業は 100%で最も高いことが分かる([図 2.62])。



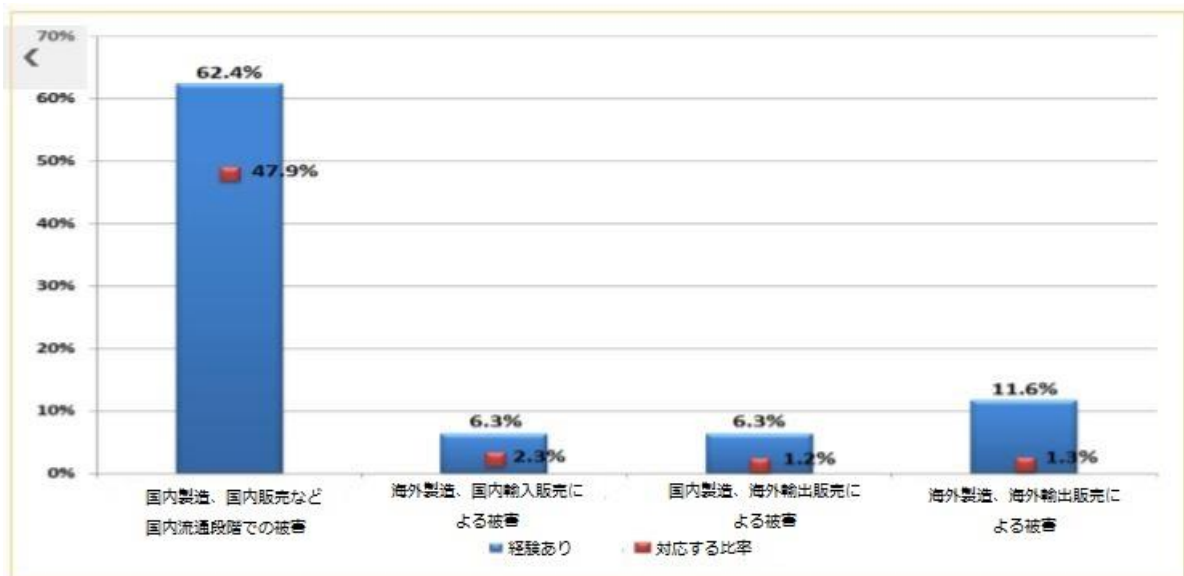
[図 2.62] 企業類型別の国内企業に対する侵害対応法

一方、海外企業に警告書を発送した比率は中堅企業が 58.4% で最も高い ([図 2.63])。ベンチャー企業の場合はこのような比率が 0.0% であり、国内企業に警告書を発送する比率と相反する結果となっている。これは海外企業に警告書を発送するなど侵害対応において時間と費用、情報などの限界があるという点を暗示しており、これに対する政府の政策的な支援が必要と見られる。但し、司法的な救済手続きを申請する比率は 37.3% で他企業類型に比べて高いことが分かった。



[図 2.63] 企業類型別の海外企業に対する侵害対応法

一方、知的財産権侵害を受けた企業の中で国内製造、国内販売など国内流通段階で被害を受けた企業の比率は 62.4%で、国内流通段階で被害を受けた企業の中で対応する企業の比率は 47.9%となっている([図 2.64])。その他に海外製造、国内輸入販売によって被害を受けた場合は 6.3%で、このうち対応する比率は 2.3%、国内製造、海外輸出販売による被害は 6.3%、このうち対応する比率は 1.2%となっている。また、海外製造、海外輸出販売によって被害を受けた比率は 11.6%、このうち対応する比率は 1.3%となっている。

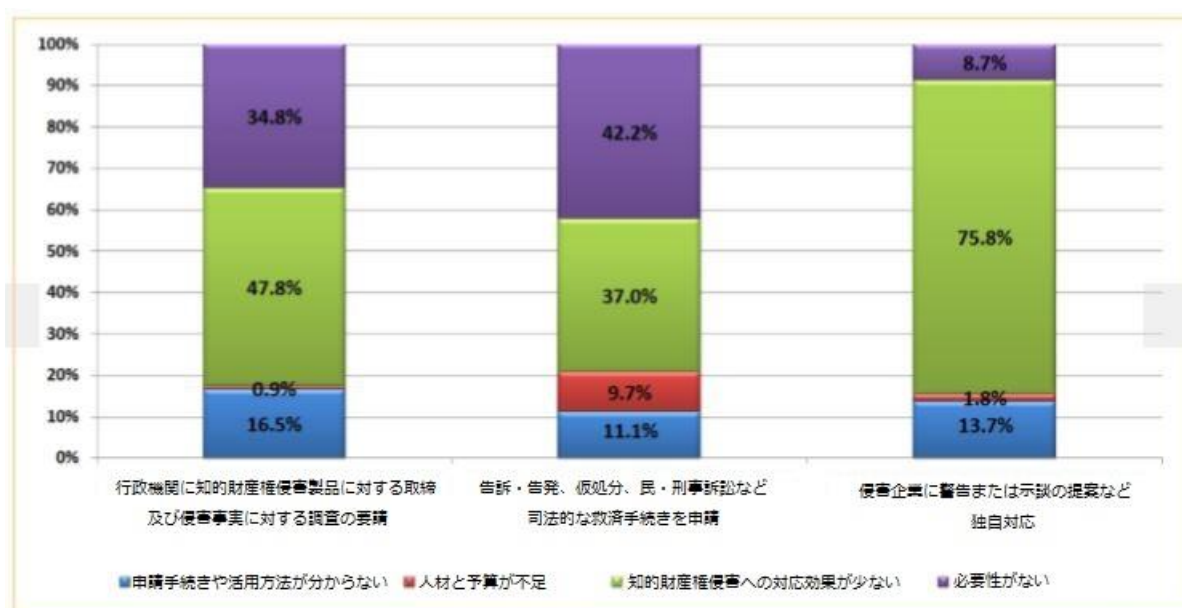


[図 2.64] 侵害製品の流通類型別の対応状況

知的財産権侵害被害に対して対応活動を行っていないと答えた場合、知的財産権侵害被害に対して対応しなかった理由を其々の対応類型別で見ると、知的財産権侵害への対応効果が少ないという回答と必要性がないため対応活動を行わなかったと答えた比率が全般的に高い。これは侵害対応活動をめぐる法、制度及びシステムの手続きが精巧化されていない点を裏付けていると言える。企業が知的財産権の侵害被害が発生して積極的に対応しても効果的な措置が取られず企業が認知する効果が極めて少ないと見られ、したがってこれに対する政府の支援策が必要と見られる。

「行政機関に取締り及び侵害事実に対する調査の要請」対応の場合、対応効果が少ないためと答えた比率が 47.8%、必要性がないと答えた比率が 34.8%で最も高い。

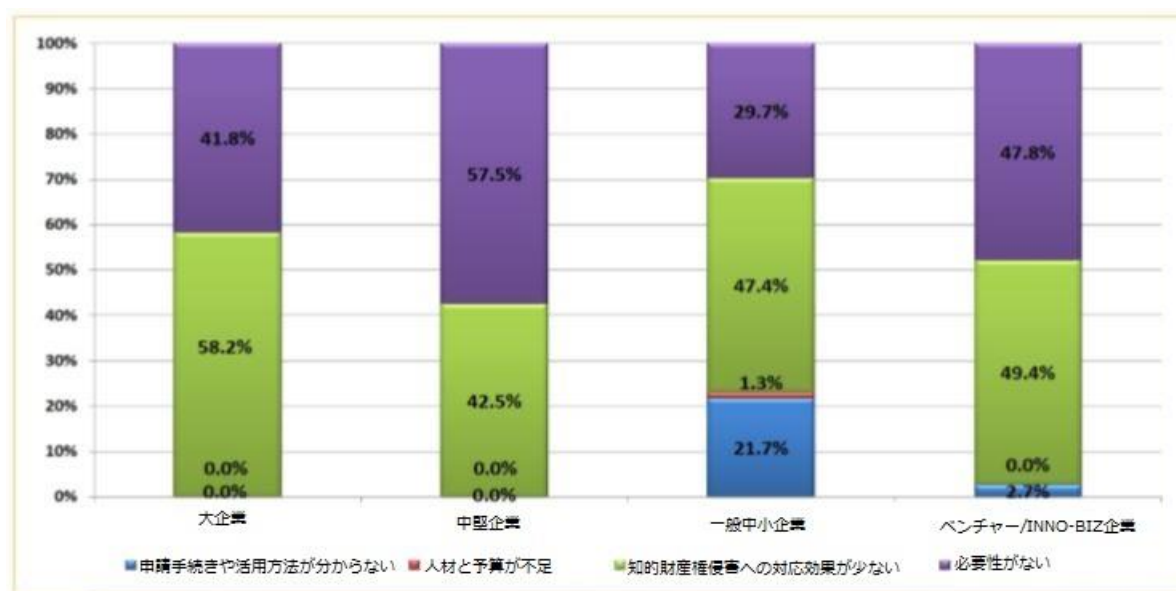
「司法的な救済手続きの申請」対応の場合にも同じく必要性がないと答えた比率が 42.2%、対応効果が少ないために対応しなかった比率が 37.0%を占めている。また、「侵害企業に警告または示談の提案など独自対応」方法を対応活動として取り入れなかった理由もまた対応効果が少ないという答えが 75.8%を占めている([図 2.65])。



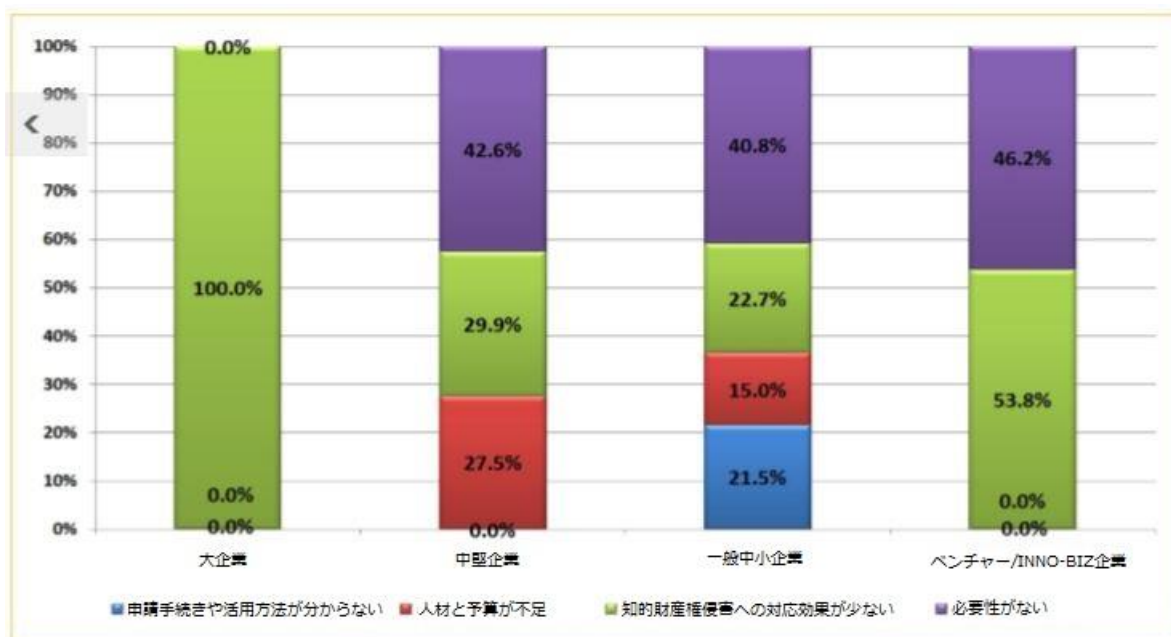
[図 2.65] 各対応類型別の対応活動を行わなかった理由

其々の対応類型によって企業類型別で見ると、いずれの対応類型において全体ととも類似した結果が見られる。即ち、知的財産侵害対応効果が少ないためであるという意見と必要性がないという意見が高い比率を占め、申請手続きや活用方法が分から

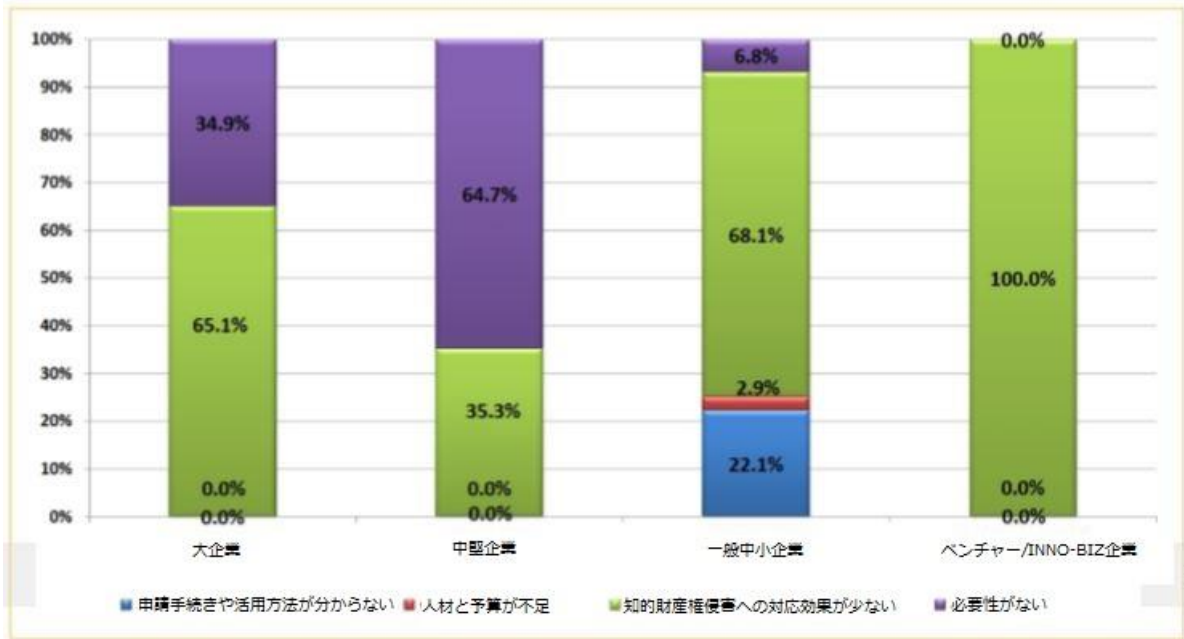
ないためまたは人材と予算の不足という意見が一部を占めた。但し、申請手続きや活用方法が分からないためまたは人材と予算の不足という回答の場合、一般中小企業が他企業類型に比べて高く、これに対する政策的な補完が求められる。



[図 2.66] 企業類型別の対応活動(行政機関に知的財産権侵害製品に対する取締り及び侵害事実に対する調査要請)を行わなかった理由



[図 2.67] 企業類型別の対応活動(告訴・告発、仮処分、民・刑事訴訟など司法的な救済措置の申請)を行わなかった理由



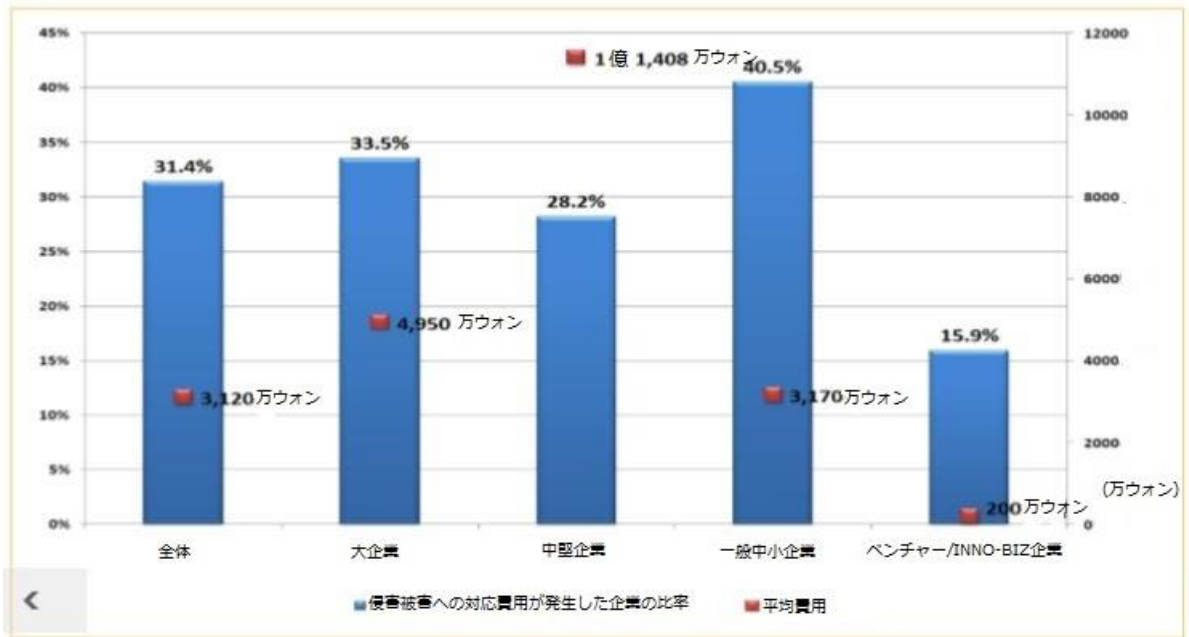
[図 2.68] 企業類型別の対応活動(侵害企業に警告または示談の提案など独自対応)を行わなかった理由

一方、2013 年に知的財産権侵害を受けた企業のうち侵害対応費用<sup>40</sup>が発生した比率は 31.4%を占め、これら企業の平均対応費用は 3,120 万ウォンとなっている([図 2.69])。

企業類型別では侵害対応費用が発生した比率は一般中小企業が 40.5%で最も高く、大企業が 33.5%、中堅企業が 28.2%、ベンチャー企業が 15.9%と続いている。ベンチャー企業の場合発生費用は 200 万ウォンで平均対応費用 3,120 万ウォンに比べて極めて低い水準である。特に、中堅企業の場合は侵害対応費用が発生した比率は比較的に低い方であるものの平均対応費用は最も高く、中堅企業の場合限定的な侵害事例の対応に費用を集中しているものと判断される。

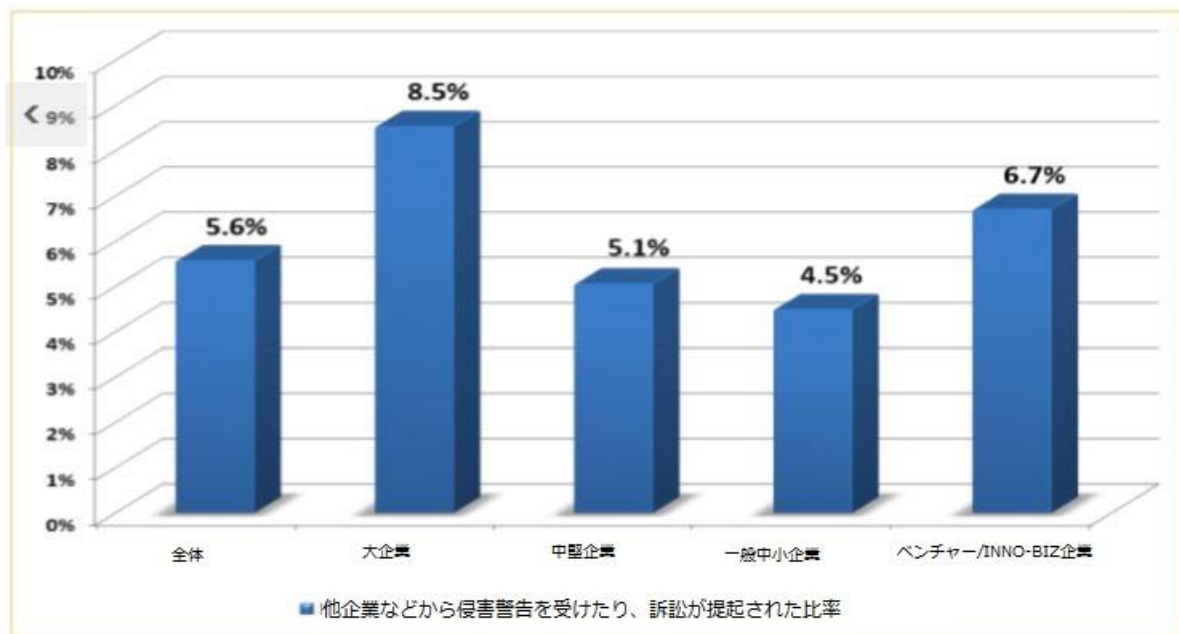
<sup>40</sup> 警告書の送付から侵害訴訟完了時までかかった費用を基準とする。(損害賠償額または示談金は除く)





[図 2.69] 知的財産権侵害対応費用

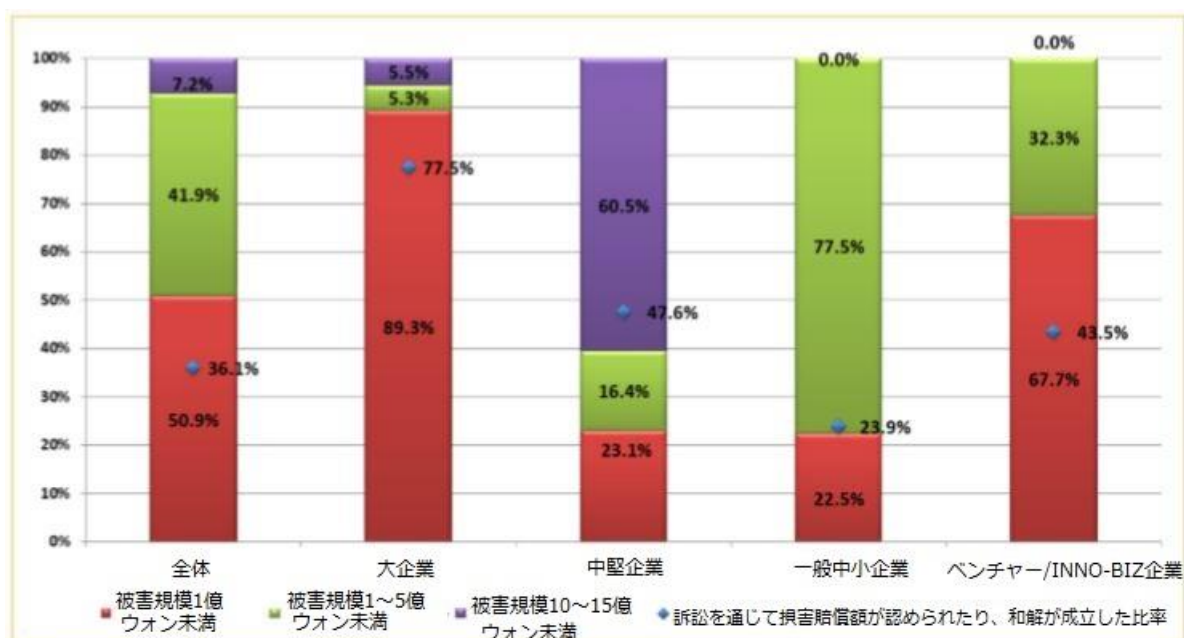
一方、他企業などから知的財産権権利侵害の警告を受けたり、訴訟が提起された企業の比率は全体の 5.6% である。大企業の場合 8.5% で最も高く、ベンチャー企業が 6.7%、中堅企業が 5.1%、一般中小企業が 4.5% となっている ([図 2.70])。



[図 2.70] 他企業などから侵害警告を受けたり、訴訟が提起された比率

### 3. 知的財産権侵害被害に対する紛争対応の結果

2013年の1年間知的財産権侵害を受けた企業のうち民事訴訟を通じて損害賠償額を認められたり、当事者間の和解が成立した比率は36.1%であった([図 2.71])。企業類型別で見ると、大企業の場合77.5%で比較的に高く、ベンチャー企業が43.5%、一般中小企業の場合23.9%で最も低い。これはベンチャー企業や一般中小企業の場合知的財産権侵害を受けても損害賠償額を認められたり、和解が成立した場合が相対的に低い可能性があることを意味する。



[図 2.71] 損害賠償額または和解金の規模

出願件数別では、年平均10件未満の企業が36.2%、年平均10~20件の企業が45.1%、年平均21~60件の企業が20.3%、年平均61件以上の多出願企業は36.6%であり、出願件数による差別性は見られなかった。

[表 2.21] 産業財産権出願規模別の損害賠償金または被害金額発生企業の比率

	年平均10件未満	年平均10~20件	年平均21~60件	年平均61件以上
損害賠償額または	36.2%	45.1%	20.3%	36.3%

和解金の 発生比率				
--------------	--	--	--	--

損害賠償額または和解金の規模は1億ウォン未満が50.9%で最も高い比率を占めているが、これは特に大企業の場合89.3%で他企業類型に比べて極めて高い方である。一方、中堅企業の場合には損害賠償額または和解金の規模が10～15億ウォンである場合が60.5%で最も高い比率を占め、企業類型に差を見せた。

2013年の1年間全体侵害被害を推定した規模は次の[表2.22]のとおりである。損害賠償額または和解金の合計が764億ウォンであり、被害企業の平均は2億2千万ウォンであった。

[表2.22] 損害賠償額または和解金の規模推定

区分	企業数 <sup>41</sup>	被害金額(2013年)(億ウォン)	
		合計	被害企業の平均
損害賠償額または 和解金	353社	764	2.2

#### <企業の輸出入有無による侵害及び紛争の実態に対する比較・分析<sup>42</sup>>

輸出入の実績有無によって輸出入活動がある企業と輸出入活動がない内需企業に対して主な数値を比較すると次のとおりである。まず、侵害比率と関連して輸出入の実績がある場合は7.1%、輸出入の実績がない企業の場合は4.2%であり、輸出入企業が相対的に侵害被害経験が多いことが分かった([図2.72])。企業が活動する市場が広がるほど、侵害可能性は高くなっているものと見られる。

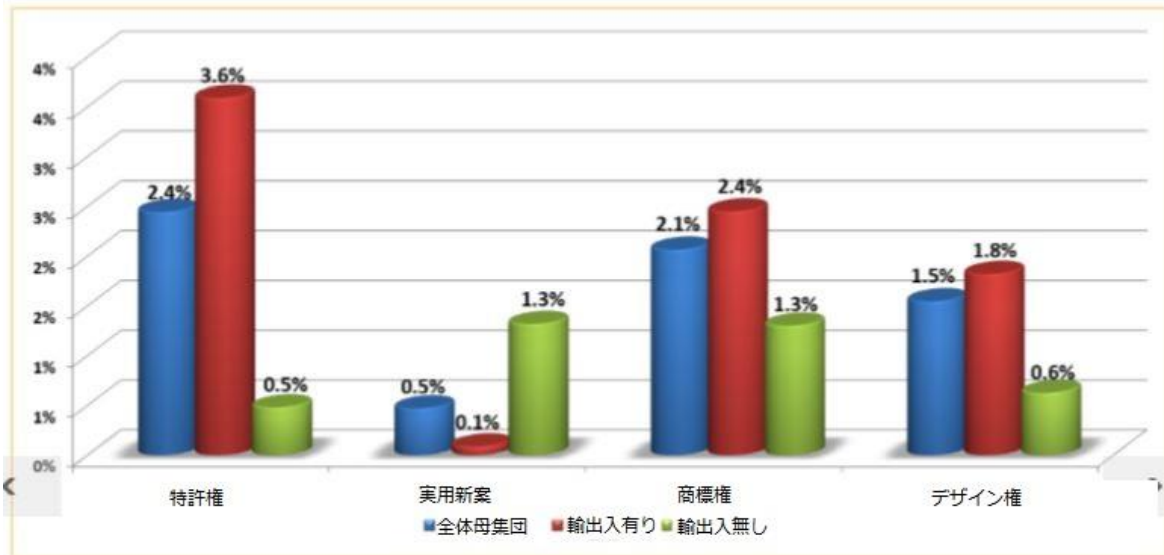
<sup>41</sup> 母集団推定値である。

<sup>42</sup> 輸出入の有無によって其々独立的に母集団を構成して推定を行った結果である。



[図 2.72] 輸出入の有無による侵害被害企業の比率

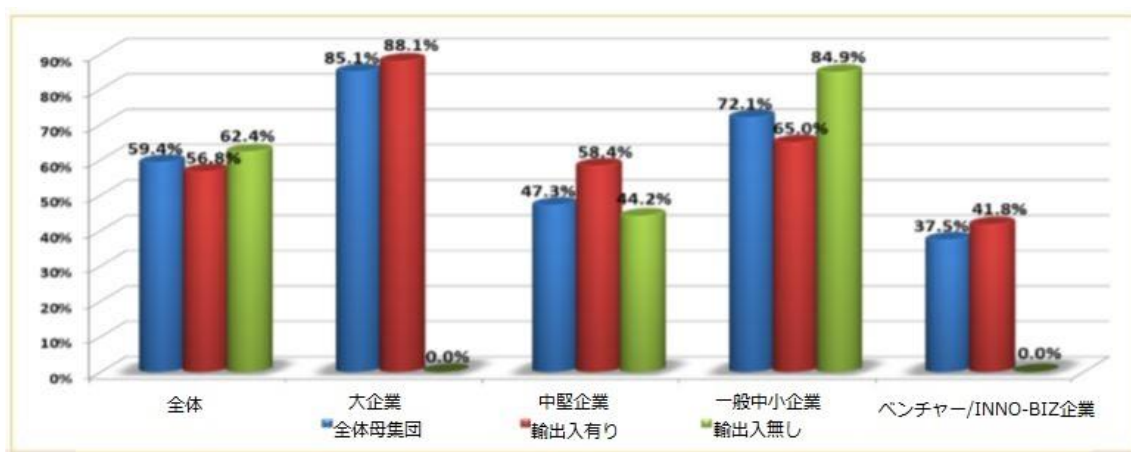
権利類型別で見ると、特許権の場合輸出入実績のある企業が 3.6%で全体企業の特許権侵害比率である 2.4%に比べて高い。一方、輸出入実績のない企業は 0.5%であり、輸出入実績のない企業が相対的に低いことが分かる（[図 2.73]）。また、商標権とデザイン権の場合も輸出入実績のある場合が其々2.4%、1.8%で、輸出入実績のない企業に比べて高いことが分かった。



[図 2.73] 輸出入の有無による産業財産権類型別の侵害被害比率

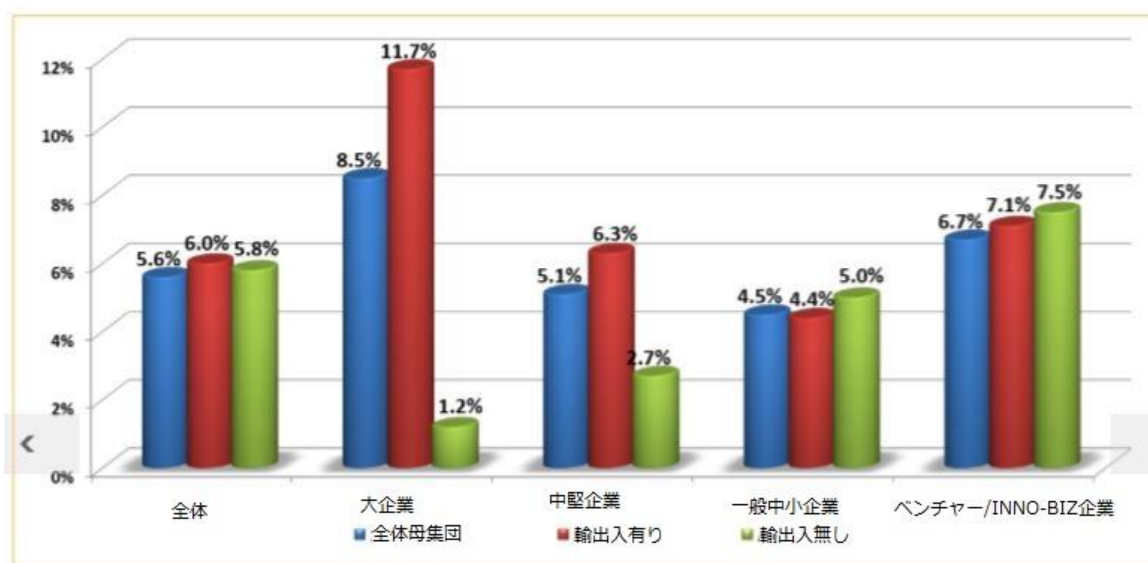
知的財産権侵害被害の経験がある場合、侵害対応比率は次のとおりである。全体に比べて輸出入実績のない企業の場合、輸出入企業に比べて対応比率が高いことが分か

った([図 2.74])。輸出入活動なく国内市場にのみ基盤を置く企業の場合、殆どの紛争が国内で発生し、対応に向けた手続きや情報などを容易に手に入れる可能性が高く、侵害により積極的に対応できる。一方、輸出入企業は海外で侵害が発生するケースが多く、これに対する対応活動が容易でないと見られる。また、輸出入企業の場合、侵害に対応することで発生し得る企業イメージの損失などを懸念して侵害対応に消極的である可能性が高いと見られる。



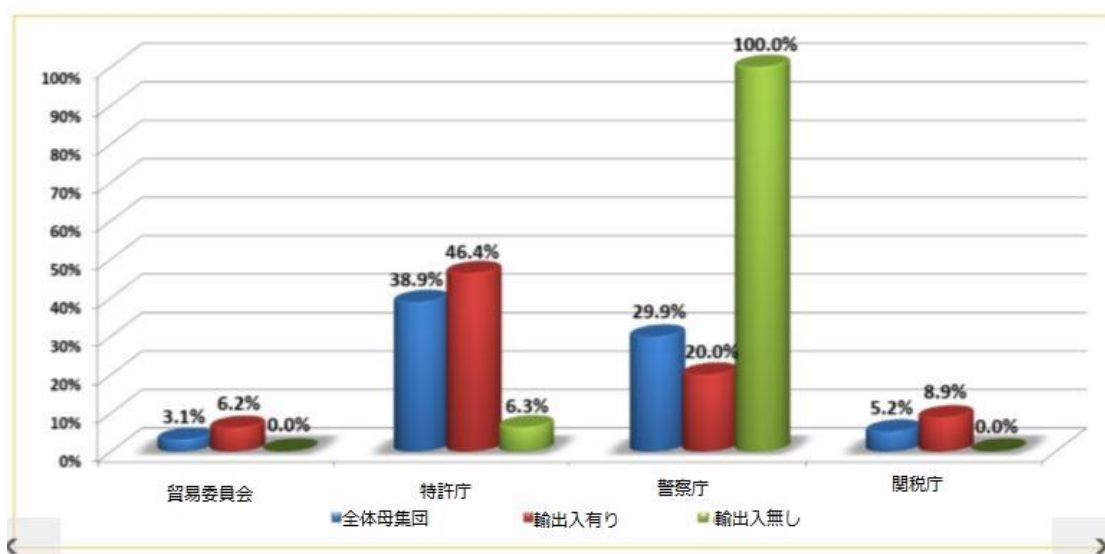
[図 2.74] 輸出入の有無による知的財産権侵害への対応比率

他企業などから警告または訴訟が提起された状況を見ると、輸出入企業の場合全体5.6%に比べて6.0%と高いことが分かった([図 2.75])。



[図 2.75] 輸出入の有無による他企業からの警告または訴訟提起の状況

知的財産権侵害被害に対する対応を依頼した機関を見ると、輸出入活動のある企業の場合は貿易委員会に依頼するケースが全体 3.1%に比べて 6.2%と相対的に高いことが分かった。関税庁に依頼する場合もまた全体 5.2%に比べて 8.9%と相対的に高い([図 2.76])。



[図 2.76] 輸出入の有無による侵害対応の依頼機関

#### 4. 知的財産権侵害及び紛争関連の問題及び必要な政策支援

知的財産権侵害対応における問題として「対応する際に過剰な時間と費用がかかること」を挙げた企業は全体の 81.1%で最も高く([表 2.23])、一般中小企業とベンチャー企業の場合にはこのような部分が特に高い比率で指摘された。後は「知的財産権保護のための行政的・司法的な救済手続きの不備」を挙げた企業が 63.5%と続いている。ベンチャー企業の場合、特に企業規模による難しさを訴えて内部専門人材の不足による知識習得が難しく関連法規などに対する情報が足りないと答えたため、これに対する政策的な補完が必要と見られる。同時に、独自対応が相対的に容易である大企業や中堅企業に比べて一般中小企業やベンチャー企業の場合、侵害対応関連情報の不足で侵害対応に難航していることが分かった。

[表 2.23] 知的財産権侵害対応における問題

	全体	大企業	中堅企業	一般中小企業	ベンチャー /INNO-BIZ 企業
知的財産権法規など関連事項に対する情報不足	53.2%	12.3%	15.1%	50.2%	82.4%
内部人材の専門性不足による関連知識習得が難しい	55.1%	20.6%	15.1%	51.3%	84.6%
紛争対応関連の政府支援政策の不足または関連情報の不足	47.9%	16.1%	22.1%	44.4%	71.6%
紛争対応のための法律代理人選定が難しい	37.1%	15.4%	12.9%	35.4%	54.0%
紛争対応の際に過剰な時間と費用がかかる	81.1%	28.5%	56.9%	84.4%	97.6%
知的財産権保護に向けた行政的、司法的な救済手続きの不備	63.5%	11.6%	51.7%	65.7%	77.6%

最後に、知的財産権侵害に対応するため必要な政府政策として「実効性のある行政的・司法的な処罰措置の強化」、「知的財産権侵害に対応するための訴訟などの費用支援」、「迅速な権利救済のための国境措置対象知的財産権の範囲を拡大、侵害物品の国内流入のシャットアウト」が必要と答えた企業の比率は其々67.6%、66.3%、66.0%と比較的に同水準となっている([表 2.24])。

必要な政府政策と関連しては企業類型別に多少の差が見られる。大企業と一般中小企業は「迅速な権利救済のための国境措置対象知的財産権の範囲を拡大、侵害物品の国内流入シャットアウト」、中堅企業とベンチャー企業は「実効性のある行政的・司法的な処罰措置の強化」が最も急がれる政策支援であると答えた。

[表 2.24] 知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策

	全体	大企業	中堅企	中小企	ベンチ

			業	業	ヤー /INNO- BIZ 企 業
実効性のある行政的・司法的処罰措置の強化	67.6%	59.5%	74.7%	63.0%	74.1%
迅速な権利救済のための国境措置対象知的財産権範囲の拡大、侵害物品の国内流入のシャットアウト	66.0%	69.6%	66.8%	63.5%	68.8%
知的財産権の保護及び対応活動のための情報提供	63.4%	63.4%	60.4%	60.3%	68.6%
行政機関の知的財産権侵害製品に対する取締権限の強化	62.6%	54.2%	61.0%	62.3%	64.9%
知的財産権侵害製品などに対する通報褒賞金額の増額	55.6%	45.5%	61.1%	53.0%	60.1%
知的財産権侵害に対応するための訴訟などの費用支援	66.3%	63.8%	69.0%	63.0%	70.8%
侵害及び知的財産権の有効性判断機関の一元化	64.1%	52.9%	66.2%	60.9%	70.2%

### <企業の輸出入有無による問題及び必要政策の比較・分析>

知的財産権侵害への対応による問題を輸出入実績の有無によって比較して見ると、全般的に輸出入実績がない場合にむしろ侵害対応に難航していることが分かった。にもかかわらず輸出入実績のある企業や輸出入実績のない企業、いずれも「紛争の際に過剰な時間と費用がかかる」ことに大きな負担を多く感じていると見られ、「知的財産権保護のための行政的・司法的な救済手続きの不備」で困っていることが分かった。

次に輸出入企業の場合には「紛争対応関連政府支援政策の不足または情報不足」を問題として指摘し、輸出入活動のない企業の場合は「内部人材の専門性不足によって



関連知識の習得が難しい」ことを指摘した。輸出入企業の場合、海外における紛争及び対応に対する情報が不十分であるため、政府レベルの情報共有及び支援が必要と見られる。

[表 2.25] 輸出入の比較による知的財産権侵害対応時の問題

	全体	輸出入有り	輸出入無し
知的財産権の法規など関連事項に対する情報不足	53.2%	41.6%	73.7%
内部人材の専門性不足によって関連知識の習得が難しい	55.1%	40.5%	81.6%
紛争対応関連の政府支援政策の不足または関連情報の不足	47.9%	46.9%	53.1%
紛争対応のための法律代理人の選定が難しい	37.1%	31.1%	48.4%
紛争対応の際に過剰な時間と費用がかかる	81.1%	73.4%	98.0%
知的財産権保護のための行政的・司法的な救済手続きの不備	63.5%	53.4%	86.9%

必要な政府政策と関連して輸出入実績の有無によって比較して見ると、全般的に全体の結果と同じく「実効性のある行政的・司法的な処罰措置の強化」を最も高い比率で指摘しており、実質的な効果が見られる政府措置方策を講じることが急がれる。輸出入活動のある企業の場合は「侵害及び知的財産権の有効性判断機関の一元化」を次に必要な政策と回答した。

[表 2.26] 輸出入の比較による知的財産権侵害対応のために必要な政府政策

	全体	輸出入有り	輸出入無し
迅速な権利救済のための国境措置対象知的財産権範囲の拡大、侵害物品の国内流入のシャットアウト	67.6%	67.3%	69.4%
知的財産権の保護及び対応活動のための情報提供	66.0%	66.4%	65.5%

行政機関の知的財産権侵害製品に対する取締 権限の強化	63.4%	63.6%	66.2%
知的財産権侵害製品などに対する通報褒賞金 額の増額	62.6%	62.0%	64.8%
知的財産権侵害に対応するための訴訟などの 費用支援	55.6%	55.3%	56.8%
侵害及び知的財産権の有効性判断機関の一元 化	66.3%	66.9%	65.9%
迅速な権利救済のための国境措置対象知的財 産権範囲の拡大、侵害物品の国内流入のシャ ットアウト	64.1%	63.9%	66.3%

#### <知的財産権の侵害及び紛争、保護関連政府支援政策及び制度>

国内外的に知的財産権の侵害及び紛争対応、保護と関連する政府支援制度として貿易委員会、特許庁、中小企業庁などの多様な制度及び事業が施行されてきた。このような政府政策及び支援事業を詳しく見ると次のとおりである。

まず、貿易委員会が運営する「不公正貿易行為調査制度」は不公正貿易行為を調査し、貿易委員会の議決を経て制裁措置を取ることで公正貿易秩序の確立が目的である。不公正貿易行為は、知的財産権侵害物品などの海外から国内への供給、輸入・販売、輸出・輸出目的の国内製造行為、原産地表示違反物品の輸出入行為、品質などの虚偽・誇張表示物品の輸出入行為及びその他輸出入秩序阻害行為など4つの類型がある。不公正貿易行為調査は不公正貿易行為のあった日から1年以内に誰でも書面で申請可能であり、調査開始決定後6か月以内に判定して不公正貿易行為として判定された場合は課徴金の賦課及び是正措置を命じることができる。また、貿易委員会は不公正貿易行為によって回復できない被害を受けている、もしくは被害を受ける恐れがある場合は申請または職権で該当物品の輸出入中止など暫定措置を命じることができる。一方、貿易委員会は不公正貿易行為を効率的に監視・摘発するため、知的財産権

侵害、原産地表示の違反行為などが頻発する 14 の業種団体を「不公正貿易行為通報センター」として指定・運営している。

特許庁の「産業財産権紛争調停制度」の場合、産業財産権争いにかかる費用と時間の負担を考慮し、特許庁が設置した産業財産権紛争調停委員会を通じて相互間の合意が導き出せるようにする制度である。紛争調停を申請する際、専担調停部を構成して当事者を紛争解決の手続きに直接参加させることで、相互間の合意を通じて紛争の解決を導き出せるように支援した。

同時に、特許庁の「国際知的財産権紛争対応支援」及び「国際知的財産権紛争情報提供」の場合、紛争予防コンサルティング、紛争動向及び訴訟事例などの情報提供などを通じて企業の知的財産活動を支援してきた。前者の場合輸出商品に対する知財権紛争の可能性、海外展示会に参加する時に発生し得る紛争などを事前に調査及び分析してその予防戦略を提供するコンサルティングを支援することで輸出紛争を予防した。特に、中堅企業を対象に知財権侵害に対応可能な交渉及び訴訟戦略、または外国企業から受け取った警告書などに対して対応戦略をコンサルティングすることで企業の紛争対応策を支援した。これを通じて国際特許紛争の危険に晒されている企業の輸出競争力を高めた。また、後者の場合、国内外国際知財権紛争の動向、法律的な争点及び判決動向など関連 이슈を提供し、特許管理会社の活動状況を調査・分析して提供した。特に、海外進出の際に知財権紛争に対応するために現地情報を盛り込んだガイドブックを提供することで国際知財権紛争のための企業の活動を支援できるようにした。

中小企業を中心とする侵害対応に向けた支援事業もある。中小企業庁の「侵害事件に対する民事訴訟費用支援事業」の場合、産業財産権の侵害を受けて侵害訴訟が必要な社会的な弱者を支援することを趣旨として侵害訴訟代理費用を支援する事業である。また、特許庁と韓国貿易協会は共同で中小企業を対象に「海外出願費用支援事業」を通じて中小企業が知的財産権の権利確保のために海外に出願する場合、その費用の一部を支援することもある。

その前に問題及び必要な政策ニーズとして指摘された紛争対応にかかる過剰な時間

と費用に対する直接的な支援、実効性のある行政的・司法的な措置などのために上記の様々な政策及び制度が行われており、以後追加的な補完が必要と判断される。特に、中堅、中小企業を中心とする多様な制度のみならず、技術を基盤として小規模で活動するベンチャー企業のような場合、紛争に対応するための能力及び環境が不十分である場合が多いため、それに対する補完が求められる。

[表 2.27] 知的財産権の侵害及び紛争、保護関連の政府支援政策及び制度

事業名	主管機関	事業概要
不公正貿易行為 調査制度	産業通商資 源部貿易委 員会	知的財産権の侵害及び原産地表示違反物品の輸出入など不公正貿易行為に対して課徴金賦課、是正措置命令など制裁措置をとることで公正貿易秩序を確立(調査開始後判定までかかる期間は 6 か月以内で、裁判所訴訟に比べて短期間・低費用で迅速な権利保護が可能)
産業財産権紛争 調停制度	特許庁	産業財産権に関する争いがある場合、裁判所や審判を通じて解決する場合にかかる費用と時間などを節約できるように特許庁が設置した「産業財産権紛争調停委員会」において当事者を紛争解決手続きに直接参加させて相互間の合意を導き出す制度
国際知的財産権 紛争対応支援	特許庁(韓国 知識財産保 護協会)	国際特許紛争の危険に晒されている中小企業及び中堅企業の特許紛争支援を通じた輸出競争力の向上
国際知的財産権 紛争情報提供	特許庁(韓国 知識財産保 護協会)	国際知財権紛争関連の情報(国際知財権紛争の動向、訴訟事例、特許管理会社分析報告書、海外知財権保護ガイドブックなど)を提供する国際知財権紛争ポータル運営
侵害事件に対す る民事訴訟費用 支援事業	中小企業庁	産業財産権の侵害を受けて侵害訴訟が必要な社会的な弱者を支援

海外出願費用支援事業	特許庁、貿易委員会	中小企業が海外で知的財産権を権利化するために特許、商標、デザインを出願する場合、それにかかる出願料、翻訳料、審査請求料、代理人費用など出願費用の一部を支援する事業
社会的な弱者の知的財産権保護支援	特許庁(韓国知識財産保護協会)	経済的な理由などで産業財産権に関する法律サービスが利用できない弱者に権利確保から紛争対応に至る全過程を支援することで公正社会の実現に貢献
海外知識財産センター(IP-DESK)	大韓貿易投資振興公社、韓国知識財産保護協会	海外進出企業が直面する現地知財権関連の問題に対して相談及びコンサルティングなどを提供し、政府間協力チャンネルの構築で海外における韓国企業の知財権保護を強化
知財権訴訟保険	韓国知識財産保護協会	韓国企業が競合社との知財権紛争を予防・対応できるように支援することで韓国企業の輸出競争力を高められるように保険を通じて紛争費用を支援

## 第 3 章 大学及び公共研究機関の 知的財産活動

第 1 節 知的財産活動インフラ

第 2 節 特許基盤の知的財産活動

第 3 節 知的財産の創出及び活用活動

第 4 節 知的財産の保護

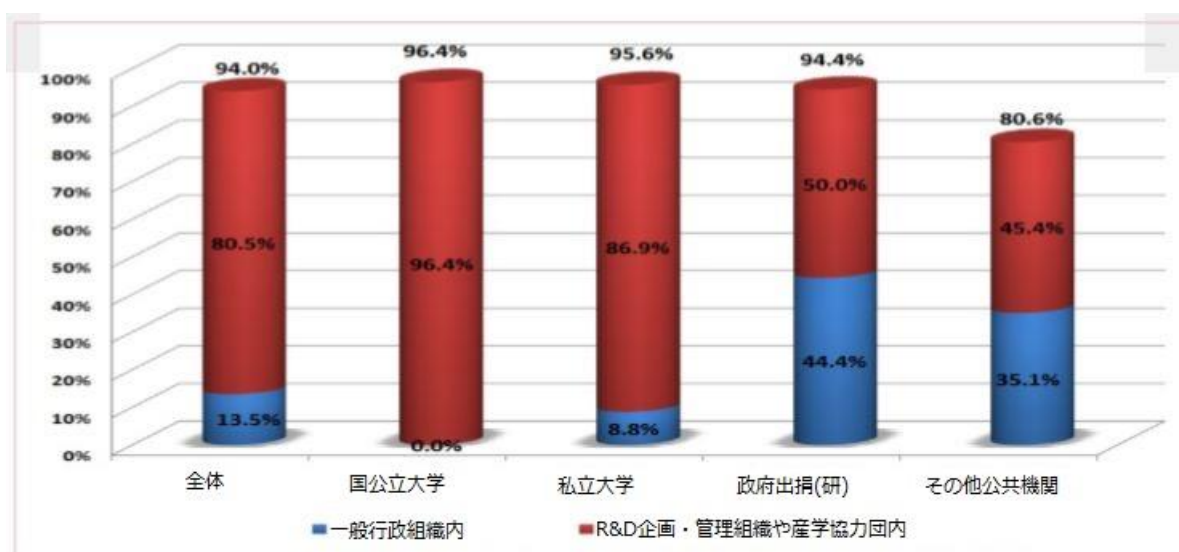
第 5 節 知的財産の侵害及び紛争

### 第3章 大学及び公共研究機関の知的財産活動

#### 第1節 知的財産活動インフラ

##### 1. 知的財産担当組織及び人材

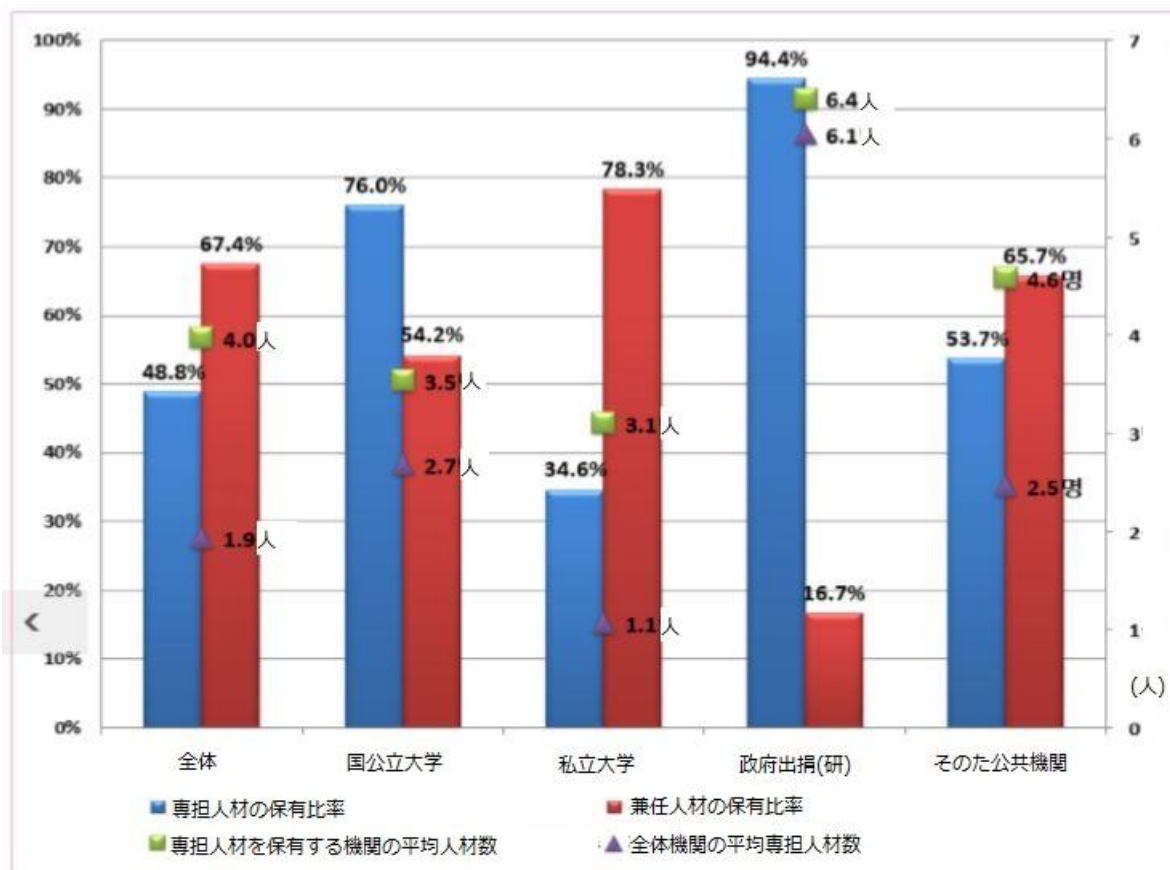
知的財産担当組織を保有している国内の大学及び公共(研)の比率は 94.0% (95.5%) となっている([図 3.1])。これを細分化すると知的財産担当組織が一般行政組織の中に存在する比率が 13.5% (12.9%)、R&D 企画・管理組織や産学協力団内に存在する比率が 80.5% (82.7%) となっている。機関類型別で見ると、国公立大学の 96.4% (100%)、私立大学の 95.6% (97.2%)、政府出捐(研)の 94.4% (同一)が知的財産担当組織を保有していることが分かる。その他公共機関の場合 80.6% (同一)が知的財産担当組織を保有しており、最低となっている。



[図 3.1] 知的財産担当組織の状況

国内大学及び公共(研)のうち知的財産関連の業務だけを専門的に担当する専門担当人材を保有している比率は 48.8% (49.0%) となっている([図 3.2])。機関類型別では政府出捐(研)の 94.4% (同一)が専門担当人材を保有しており、最も高い。知的財産専

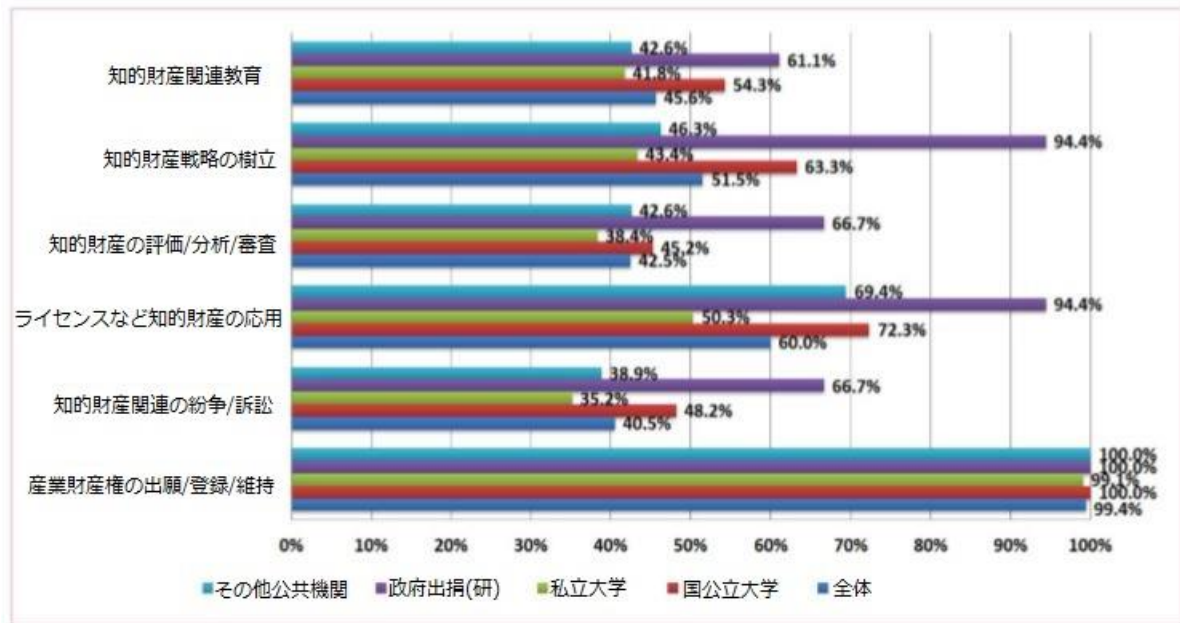
担人材を保有している機関の平均専担人材数は 4.0 人(同一)、機関全体平均専担人材数は 1.9 人(2.0 人)となっている。国公立大学と政府出捐(研)の場合専担人材を保有する比率が兼任人材を保有する比率より高く、特に政府出捐(研)の場合その格差が極めて大きいことが分かった。また、一方の私立大学とその他公共機関の場合専担人材より兼任人材を保有する機関の比率が相対的に高い。



[図 3.2] 知的財産専門担当人材の保有状況

国内大学及び公共(研)は知的財産兼任人材を平均的に 1.1 人(同一)保有しており、知的財産兼任人材を保有する機関の平均兼任人材数は 1.6 人(同一)となっている。兼任人材を保有する機関の平均兼任人材数を機関類型別で見ると、その他公共機関の場合 3.0 人(同一)で最も多く、政府出捐(研)の場合が 2.0 人(同一)と続いている。



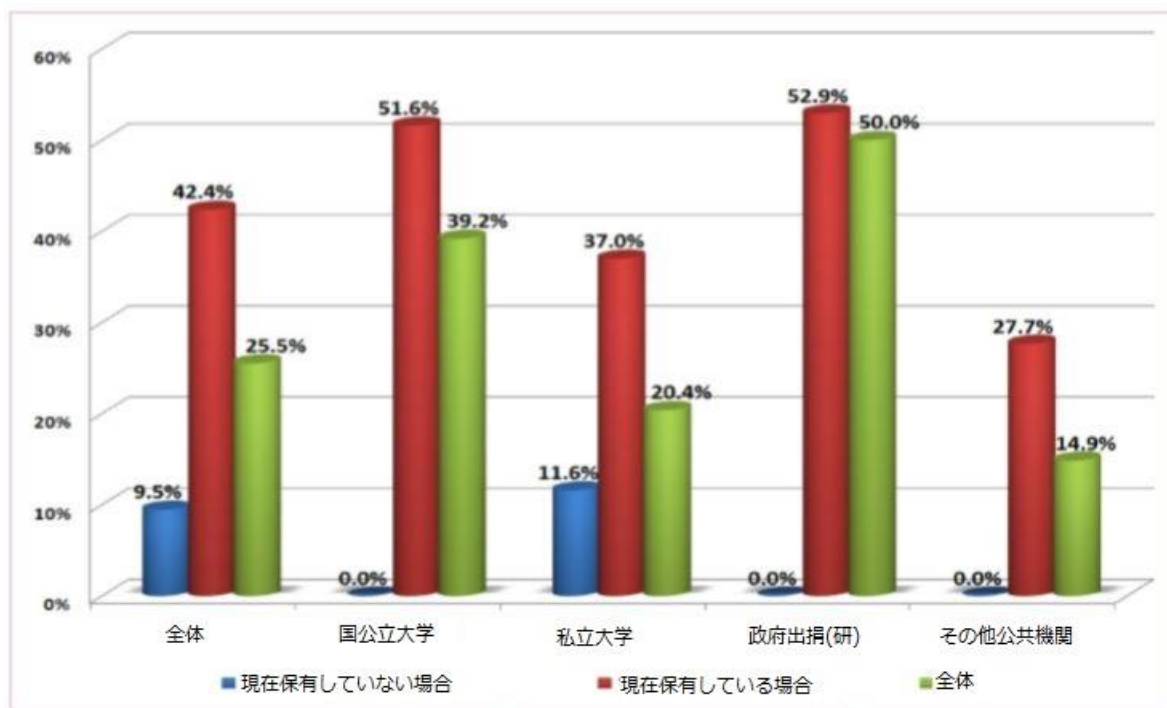


[図 3.3] 知的財産担当者の主要業務

知的財産担当人材(兼任人材を含む)を1人以上保有している場合、該当人材が産業財産権の出願/登録/維持業務を担当する比率は99.4%(同一)となっている。([図3.3])。また、ライセンスなど知的財産活用関連業務と知的財産戦略の樹立業務を行っている比率は其々60.0%(60.5%)と51.5%(52.2%)となっている。知的財産関連教育を担当していると答えた比率は45.6%(同一)、知的財産の評価/分析/審査及び知的財産関連紛争業務を担当する比率は42.5%(42.9%)、40.5%(41.6%)となっている。

一方、国内大学及び公共(研)の25.5%(同一)は今後知的財産専担人材を採用する計画を持っていると答えている([図3.4])。特に、現在専担人材を保有していない場合の9.5%(8.9%)が新規採用計画を持っており、現在保有している場合の42.4%(42.7%)は追加採用計画があると答えている。機関類型別で見ると、私立大学の場合現在保有していない場合の11.6%(10.9%)が新規採用計画を持っており、現在保有している場合にも37.0%(37.9%)が追加採用計画があると答えている。国公立大学及び政府出捐(研)、その他公共機関の場合は現在保有していない場合は新規採用計画を持っている比率が非常に低く、一方現在保有している場合に限定すると追加採用計画を持っている比率は比較的が高い。このような事実は知的財産関連人材の採用において

既存の人材を強化することで担当業務の品質向上及び集中を図っているものと判断できる。

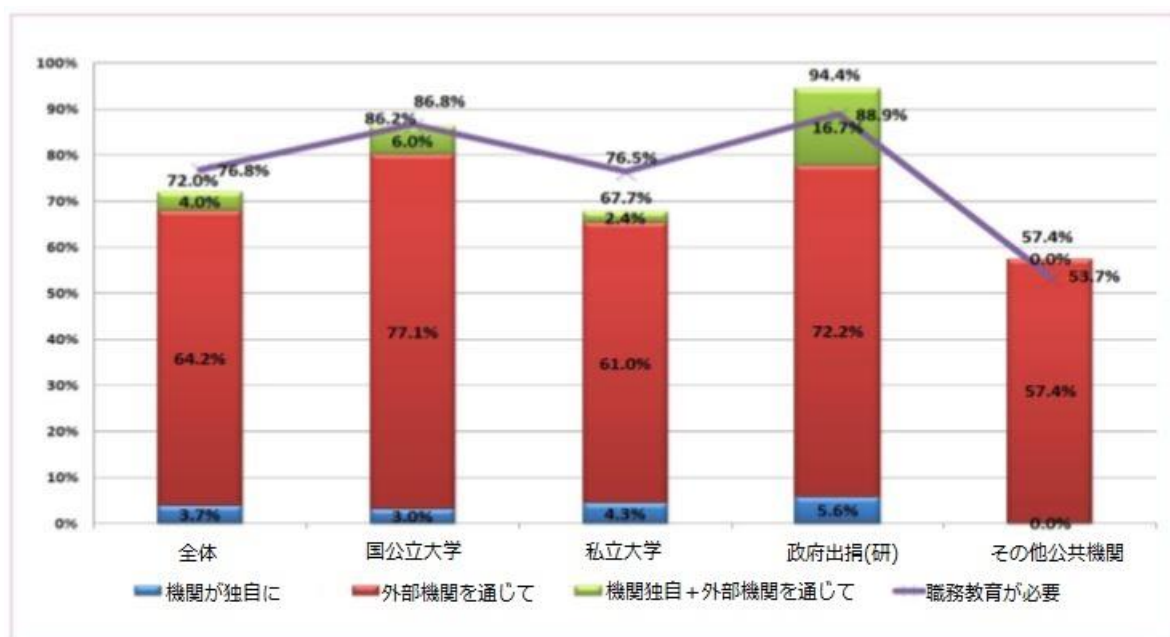


[図 3.4] 知的財産担当人材の採用計画

## 2. 知的財産担当人材に対する職務教育及び人件費・教育費

国内大学及び公共(研)のうち外部機関を通じて、または機関独自に知的財産担当人材に対して職務教育を行っている比率が其々64.2%(65.3%)と3.7%(4.0%)となっており、外部機関及び機関独自に同時に実施している比率は4.0%(4.1%)を占めている([図 3.5])。即ち、全体の72.0%(73.4%)は知的財産担当人材に対する職務教育を実施していると言える。機関類型別では、国公立大学の86.2%(88.3%)が担当人材の職務教育を行っており、政府出捐(研)の場合も94.4%(同一)が教育を実施しており、他機関に比べてその比率が高い。私立大学及びその他公共(研)の其々32.3%(30.8%)と42.6%(同一)は知的財産担当人材に対する職務教育を全く行っていないことが分かった。

一方、全体の76.8% (78.3%)が知的財産担当人材に対する職務教育が必要またはとも必要であると答えており、実際に行っている比率の72.0% (73.4%)より多少高い。特に、私立大学の場合は職務教育が必要と答えた比率が76.5% (78.1%)と実際に実施している比率の67.7% (69.2%)間の格差が相対的に大きい。従って、この部分に対する政策支援が求められる。



[図 3.5] 知的財産権担当人材に対する職務教育の状況及び必要性

注. 複数回答

知的財産人材向けの職務教育の実施を希望する場合、主に取り扱うべき教育内容として全体の70.6% (70.5%)と60.4% (60.3%)が其々特許ライセンス(技術事業化)分野と特許制度を挙げている([表 3.1])。特許ライセンス(技術事業化)関連の職務教育が必要と答えた比率は全ての機関類型において最も高い比率となっている。

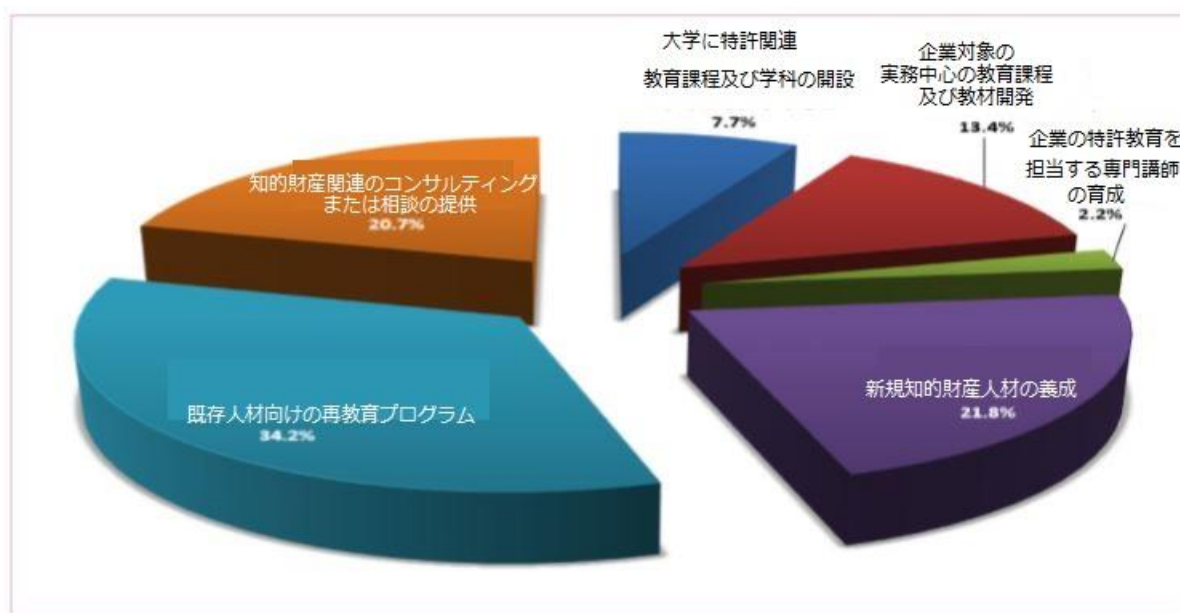
[表 3.1] 職務教育の実施を希望する場合、取り扱うべき内容

	全体	国公立大学	私立大学	政府出捐(研)	その他公共(研)
特許制度	60.4%	72.3%	60.4%	66.7%	38.0%

特許明細書の作成法	17.1%	15.7%	14.3%	27.8%	26.9%
特許情報の検索	50.8%	65.1%	48.2%	50.0%	45.4%
特許紛争(訴訟)	22.7%	22.3%	18.5%	33.3%	38.9%
特許情報の分析方法(特許マップ)	47.9%	48.8%	42.6%	72.2%	57.4%
特許ライセンス(技術事業化)	70.6%	86.2%	61.9%	77.8%	92.6%
海外特許出願及び訴訟	29.7%	18.7%	29.8%	33.3%	42.6%
営業秘密の保護	10.7%	6.0%	9.9%	5.6%	3.7%
特許契約(技術移転)の管理	1.4%	6.0%	0.0%	0.0%	3.7%

注. 複数回答

知的財産人材の能力を高めるために政府が最も急ぐべき推進課題として全体の34.2%(34.1%)が既存人材向け再教育プログラムの提供を挙げている([図 3.6])。また、新規知的財産人材の養成、知的財産関連のコンサルティングまたは相談の提供を挙げた比率は其々21.8%(21.7%)と20.7%(20.6%)となっている。



[図 3.6] 知的財産人材の能力強化のために必要な政府政策

2013年の1年間国内の大学及び公共(研)は知的財産担当者の人件費と知的財産関連の教育費として其々8,600万ウォン(8,700万ウォン)と462万ウォン(466万ウォン)を支出している([表 3.2])。国公立大学と私立大学の場合人件費対比教育費の比重が相対的に高い<sup>43</sup>ことが分かった。

[表 3.2] 知的財産担当者の人件費及び教育費の状況

	人件費 <sup>44</sup>	教育費 <sup>45</sup>	合計
全体	8,600万ウォン	462万ウォン	9,061万ウォン
国公立大学	9,244万ウォン	595万ウォン	9,839万ウォン
私立大学	4,785万ウォン	301万ウォン	5,086万ウォン
政府出捐(研)	3億2,961万ウォン	1,556万ウォン	3億4,517万ウォン
その他公共(研)	9,640万ウォン	303万ウォン	9,943万ウォン

### 3. 知的財産サービスの活用及び総合的な管理システムの構築状況

2013年に外部知的財産サービスを利用した大学及び公共(研)の比率は87.0%(89.1%)となっている([表 3.3])。特に、その他公共機関の場合には100.0%(同一)と他機関類型に比べて最も高い比率となっている。分野別平均支出額はIP翻訳に限って1年平均2,077万ウォン(2,055万ウォン)を支出して最も多い比重を占めており、政府出捐(研)の場合最も高い水準であることが分かった。IP情報調査/分析の場合は平均1,399万ウォン(1,384万ウォン)を支出し、政府出捐(研)の場合4,103万ウォン(同一)、国公立大学と私立大学、その他公共機関は其々平均2,907万ウォン(2,833万ウォン)、402万ウォン(398万ウォン)、2,360万ウォン(同一)を支出している。一方、IPコンサルティングに対する平均支出額は234万ウォン(232万ウォン)で最低となっている。

<sup>43</sup> 私立大学の場合6.3%、政府出捐(研)の場合4.7%、その他公共機関の場合3.1%。

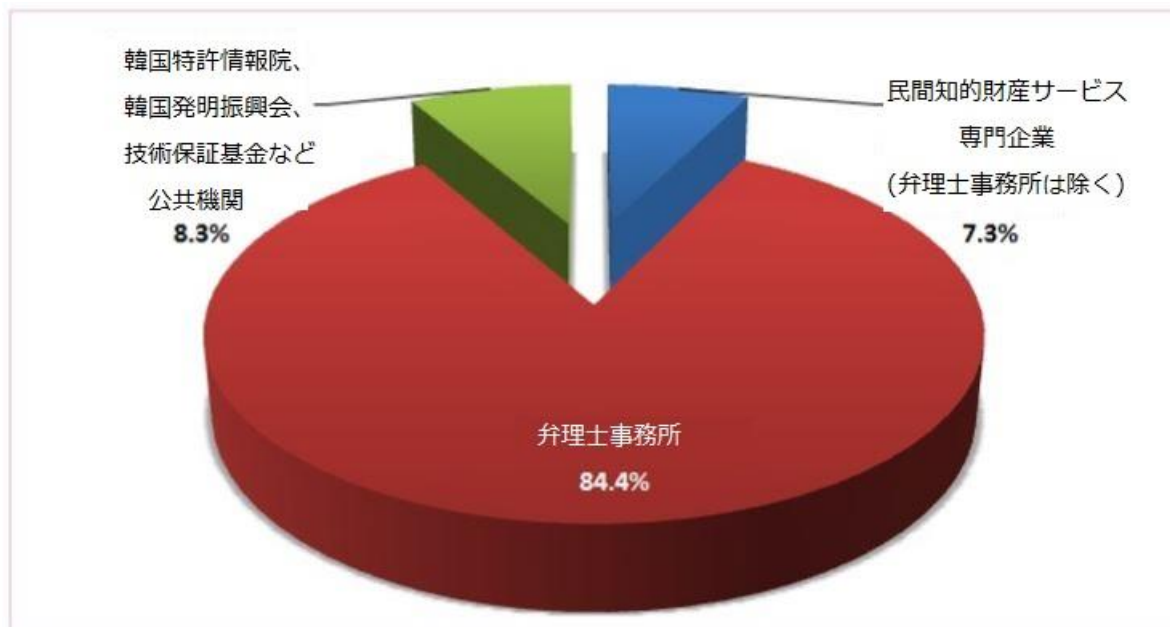
<sup>44</sup> 他の業務と兼職である場合、知的財産関連業務の比重を考慮して回答した結果である。

<sup>45</sup> 教育費は知的財産担当者対象の教育費と他従業員対象の教育費の合計である。

[表 3.3] 知的財産サービスの利用状況

		全体	国公立大学	私立大学	政府出捐 (研)	その他 公共(研)
利用している		87.0%	83.2%	84.7%	94.4%	100%
2013 年の 支出 額	IP 情報調査/分析	1,399 万ウォン	2,907 万ウォン	402 万ウォン	4,103 万ウォン	2,360 万ウォン
	技術移転/取引	1,309 万ウォン	2,048 万ウォン	694 万ウォン	3,788 万ウォン	1,489 万ウォン
	IP 翻訳	2,077 万ウォン	319 万ウォン	207 万ウォン	1億8,425 万ウォン	581 万ウォン
	IP コンサルティング	234 万ウォン	53 万ウォン	114 万ウォン	1,242 万ウォン	260 万ウォン
	IP インフラ	483 万ウォン	429 万ウォン	259 万ウォン	2,131 万ウォン	358 万ウォン
	その他	9,026 万ウォン	1億9,975 万ウォン	3,869 万ウォン	1億6,543 万ウォン	1億5,260 万ウォン
	合計	1億4,528 万ウォン	2億5,731 万ウォン	5,545 万ウォン	4億6,232 万ウォン	2億309 万ウォン

知的財産サービス提供機関別の利用比重は弁理士事務所が 84.4% (84.6%) と最も多い比重を占めている ([図 3.7])。その他に韓国特許情報院、韓国発明振興院など公共機関は 8.3% (8.2%) で、弁理士事務所を除いた民間知的財産サービス専門企業の利用比重は 7.3% (7.2%) に止まっている。

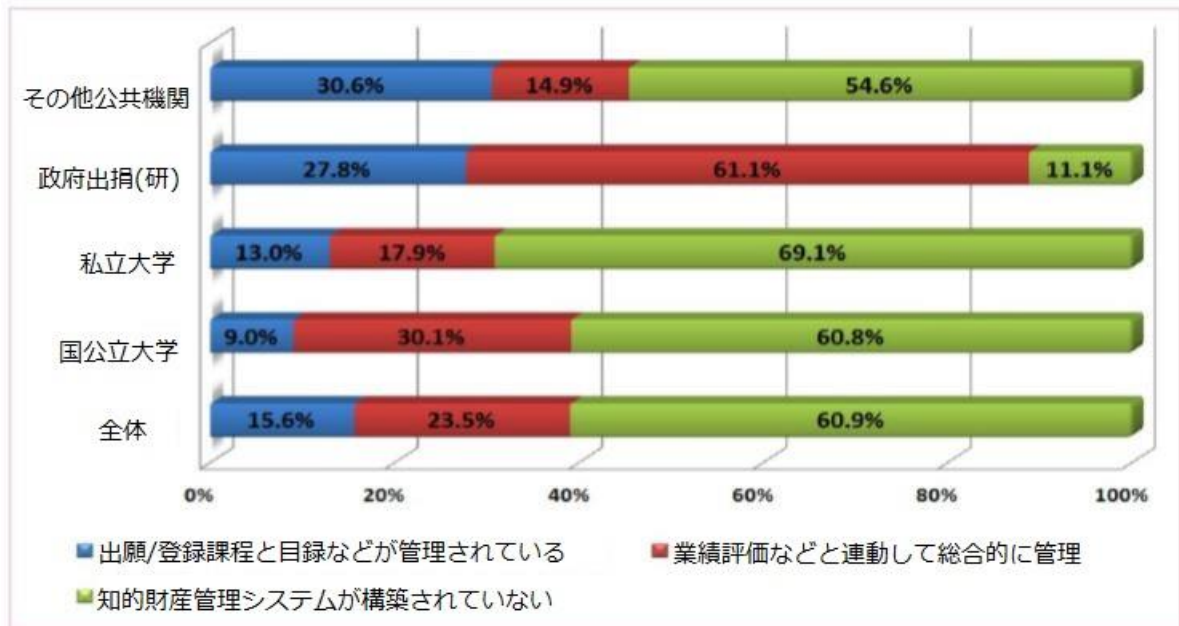


[図 3.7] 知的財産サービス提供機関別の利用比重

知的財産サービス提供機関別の利用比重は機関類型別で見ると、全ての機関類型において弁理士事務所を利用する場合は最も大きな比重を占めている。国公立大学と私立大学、その他公共研究機関の場合は公共機関を利用する比率が次に高く、其々12.1% (12.7%)、7.1% (6.6%)、3.6% (同一)となっている。政府出捐(研)の場合は民間知的財産サービス専門企業を利用する比率が次に高く、17.7% (同一)となっている。

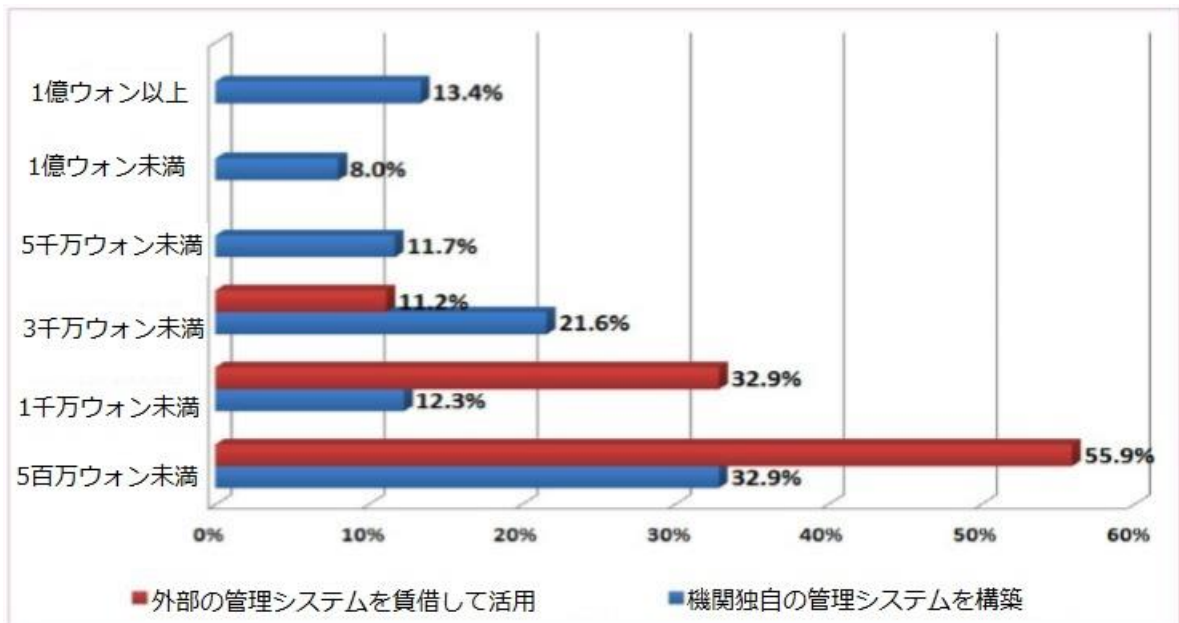
現在総合的な知的財産管理システムを構築・活用している大学、公共(研)の比率は39.1% (39.9%)となっている([図 3.8])。機関類型別では政府出捐(研)が88.9% (同一)と最も高く私立大学が30.9% (32.0%)で最低となっている。これを細分化してみると、発明届出から出願、中間事件、登録、維持、放棄などに係わる行政的な手続きと特許費用、関連情報などを管理するシステムを構築している比率が15.6% (15.9%)となっており、特許などの出願・登録過程と目録などを業績評価などの人事管理、研究課題管理システム、技術移転システムと連動させて総合的に管理している比率は23.5% (24.0%)となっている。





[図 3.8] 知的財産管理システムの構築及び活用状況

知的財産管理システムの構築・活用にかかる費用は機関固有の管理システムを構築して活用する場合 500 万ウォン未満が 32.9% (33.2%) で最も多く、1 億ウォン以上使う大学・公共研究機関も 13.4% (13.3%) となっている ([図 3.9])。外部の管理システムを借りて活用する場合も 500 万ウォン未満が 55.9% (57.1%) で最も多い。



[図 3.9] 知的財産管理システムの構築費用



## 第2節 特許基盤の知的財産活動

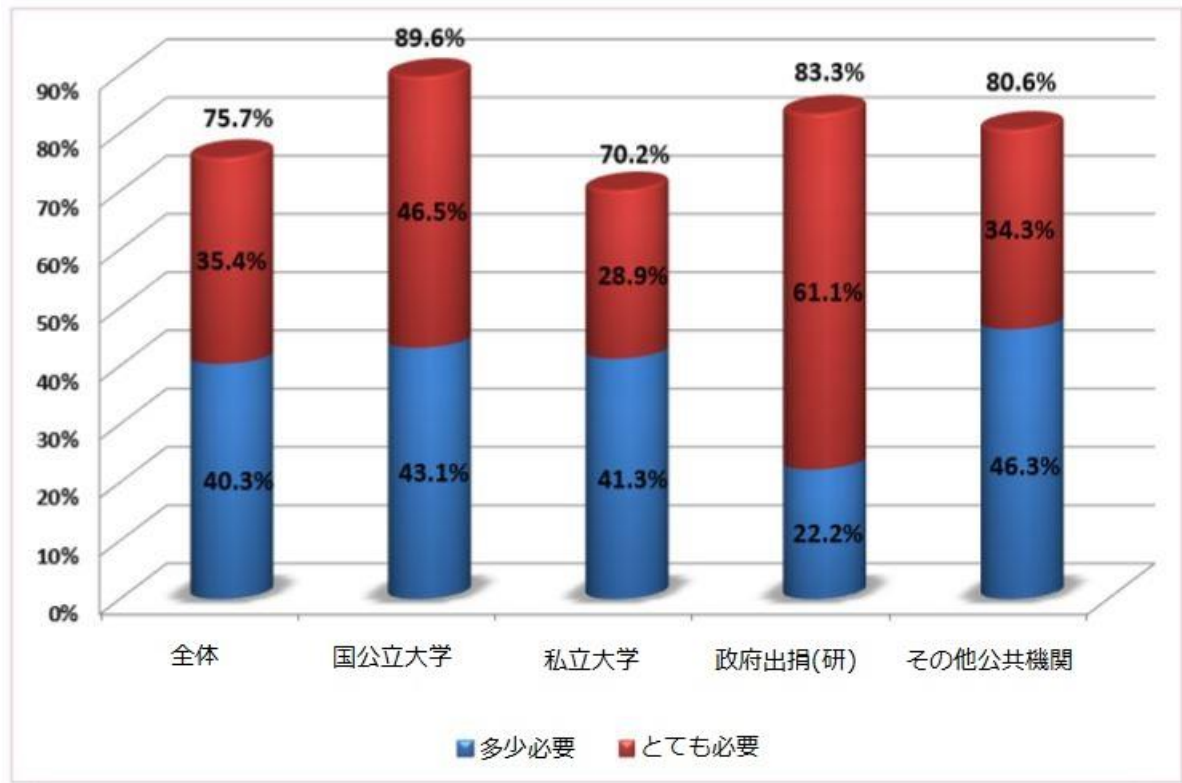
### 1. 先行特許(技術)調査など特許情報の活用

研究開発企画段階において先行特許(技術)を調査・活用している大学及び公共(研)の比率は全体の64.4%となっている([図 3.10])。機関類型別では政府出捐(研)が94.4%と最も高く、その他公共機関、国公立大学、私立大学と続いている。また、全体研究開発課題のうち調査・活用の実行比率は全体の場合58.7%となっており、国公立大学の場合が最も高い70.8%となっている。



[図 3.10] 先行特許(技術)調査の状況

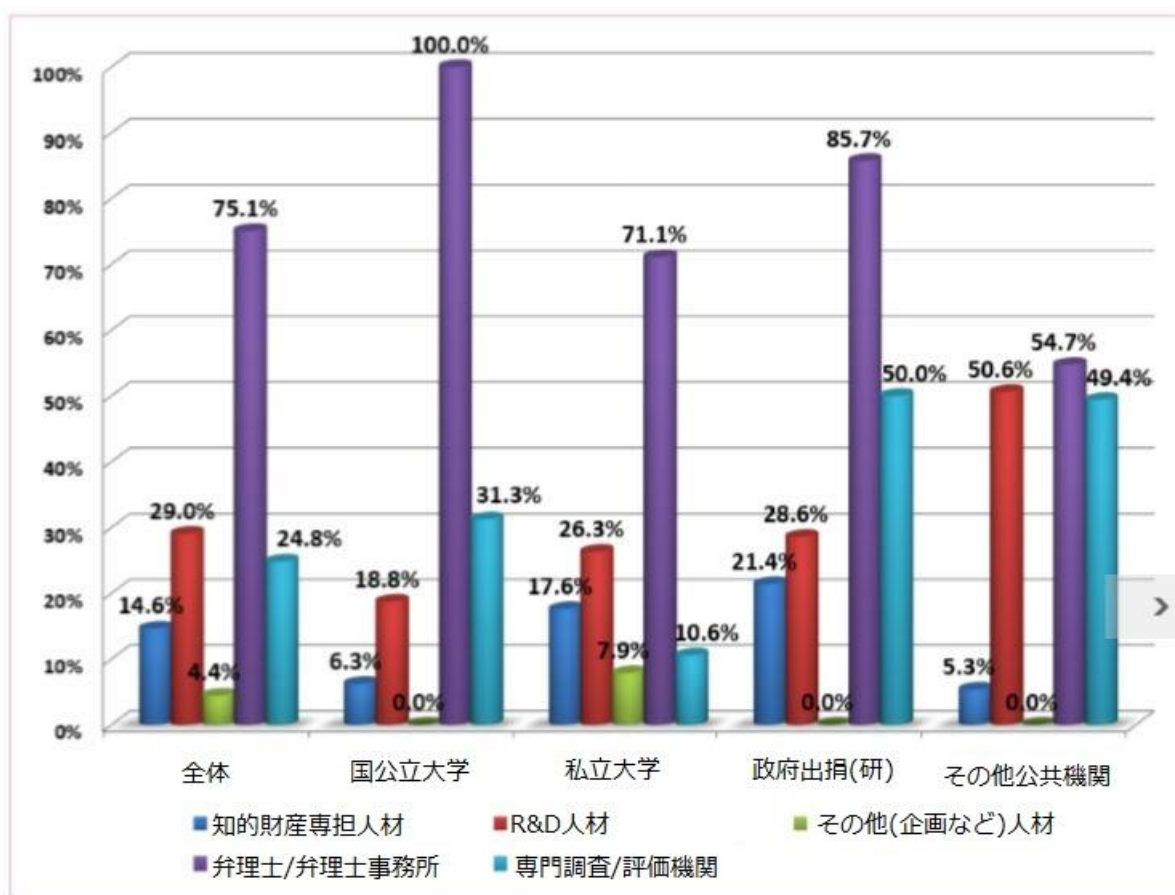
大学及び公共(研)の知的財産担当者が認識している先行特許(技術)調査の必要性和関連して全体の75.7%が必要またはとても必要と答えている([図 3.11])。機関類型別では国公立大学と政府出捐(研)の其々89.6%と83.3%が先行特許(技術)調査の必要性に対して肯定的に回答し、相対的に高いことが分かった。



[図 3.11] 先行特許(技術)調査の必要性

先行特許(技術)調査を行っている場合の 75.1%が弁理士/弁理士事務所に該当業務を依頼していることが分かった([図 3.12])。また、研究開発人材が直接行っていると答えた機関は 29.0%となっている。専門調査/評価機関、知的財産専担人材が行っていると回答した機関は其々24.8%と 14.6%である。

機関類型別で見ると、国公立大学の場合は弁理士/弁理士事務所に該当業務を依頼する比率が 100.0%で最も高く、政府出捐(研)が 85.7%、私立大学が 71.1%と続いている。その他公共研究機関の場合、研究開発人材が先行特許(技術)調査を行っている と答えた比率が 50.6%で相対的に極めて高いことが分かった。

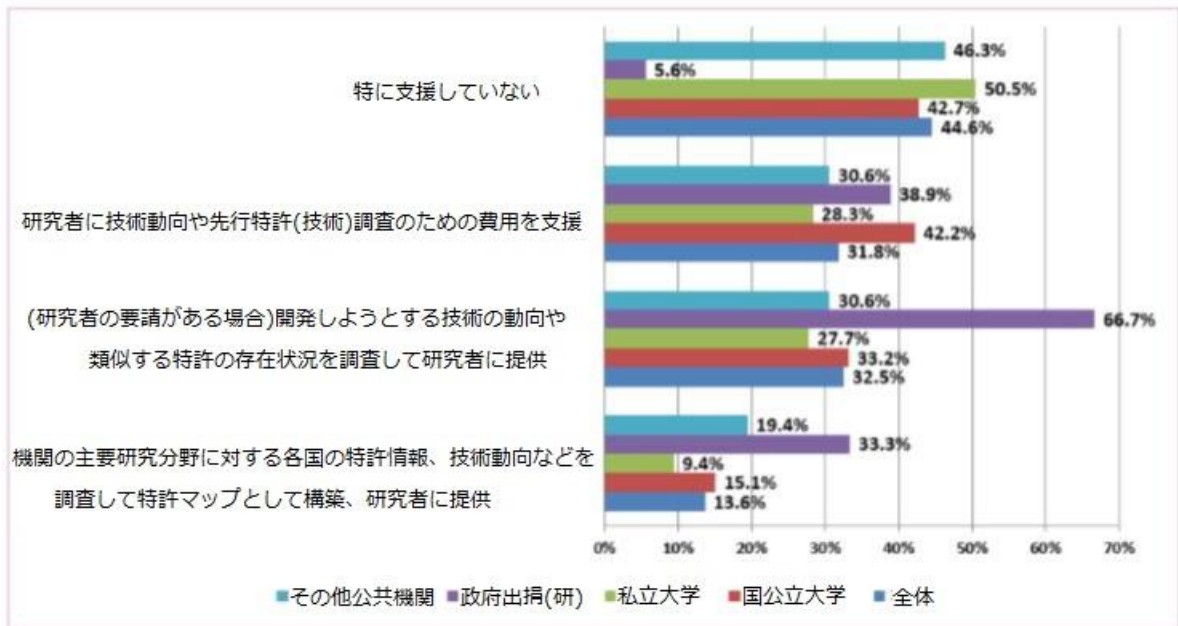


[図 3.12] 先行特許(技術)調査を行う場合の実行人材

注. 複数回答

先行特許(技術)調査のために機関レベルで支援している比率は全体の 55.4%となっている([図 3.13])。支援の種類別で見ると、全体機関の 32.5%が研究者の要請がある場合開発しようとする技術の動向や類似する特許が存在するかどうかを調査して研究者に提供している。特に、政府出捐(研)の 66.7%が該当支援を提供していることが分かった。また、全体機関の 31.8%が研究者に技術動向や先行特許(技術)調査のための費用を支援している。特に、政府出捐(研)の 38.9%、国公立大学の 42.2%が技術動向及び先行特許(技術)調査のために費用を支援していることが分かった。

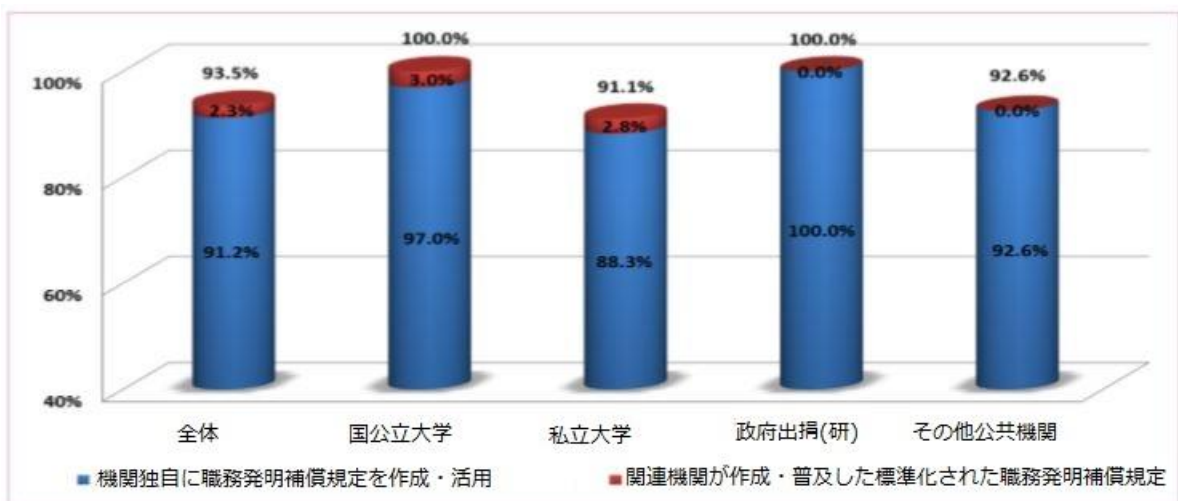
また、機関の主要研究分野に対する各国の特許情報、技術動向などを調査して特許マップとして構築、研究者に提供する比率も 13.6%となっており、機関類型別で見ると、政府出捐(研)の場合 33.3%と他機関類型に比べて高い比率を占めていることが分かった。



[図 3.13] 先行特許(技術)調査に対する機関の支援

## 2. 職務発明補償

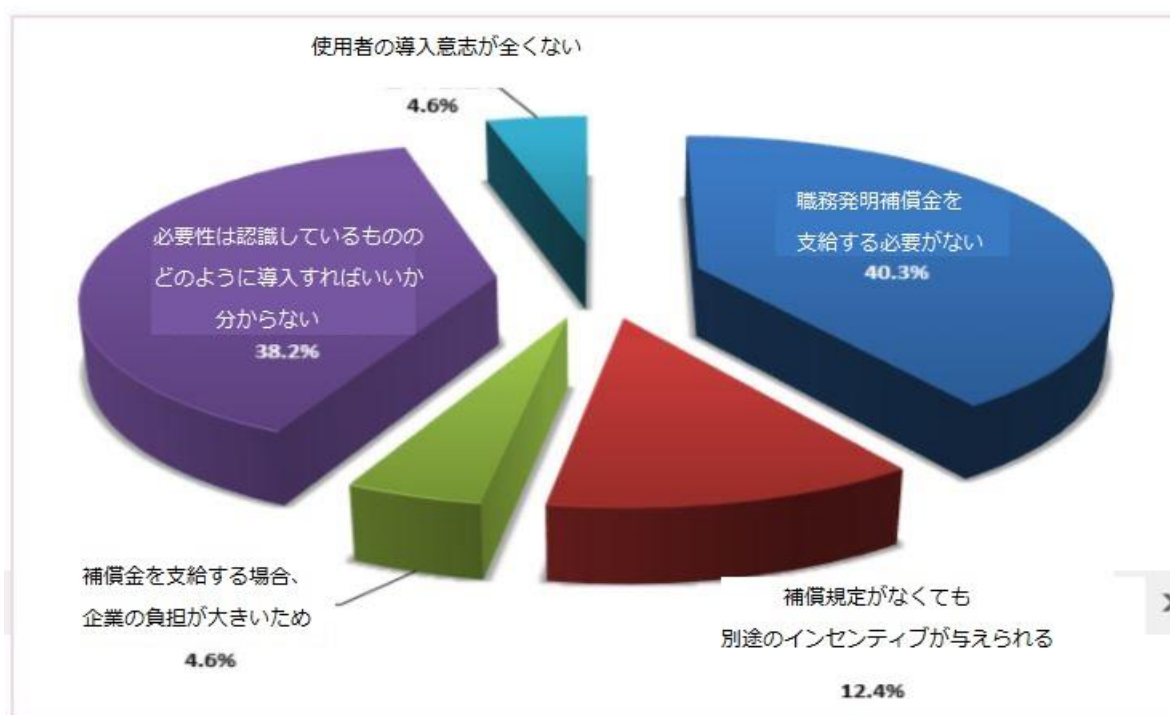
職務発明補償規定を保有し、これを活用している大学、公共(研)の比率は 93.5% (93.9%)となっている([図 3.14])。これを細分化すると、機関独自に職務発明補償規定を作成・活用している比率が 91.2% (91.6%)となっており、特許庁など関連機関が作成・普及して標準化された職務発明補償規定を保有・活用している比率は 2.3% (2.2%)となっている。



[図 3.14] 職務発明補償規定の保有及び活用状況

機関類型別では、政府出捐(研)、国公立大学、私立大学において職務発明補償規定を保有/活用している比率は其々100.0%、100.0%、92.6%で、私立大学の場合91.1%と多少低いことが分かった。

補償規定を保有していない理由として、必要性は認識しているもののどのように導入すればいいか分からないと答えた比率と補償規定がなくても別途のインセンティブが与えられるためと答えた比率が其々38.2%と12.4%と比較的に高い比率であることが分かった([図 3.15])。使用者の導入意志が全くない場合及び補償金の支給が企業の負担になるための場合も其々4.6%となっている。職務発明補償金を支給する必要がないためと答えた比率は40.3%を占めている。



[図 3.15] 職務発明補償規定を保有していない場合その主な理由

職務発明補償類型別の実施状況を見ると次の[表 3.4]のとおりである。国内特許登録補償、他社実施補償、海外特許登録補償を実施している比率が其々74.8%、74.1%、73.9%と高い。

機関類型別で見ると、国公立大学の場合は他社実施補償と処分補償比率が其々73.7%で、政府出捐(研)の場合は他社実施補償と処分補償、国内特許登録補償の比率が其々94.4%と最も高い比率を占めている。

[表 3.4]職務発明補償類型別の実施比率

	全体	国公立大学	私立大学	政府出捐(研)	その他 公共(研)
発明提案(発明届出)補償	9.5%	10.4%	7.9%	16.7%	11.1%
出願留保補償	7.4%	3.0%	6.5%	16.7%	11.1%
国内特許出願補償	38.5%	24.1%	39.9%	55.6%	38.0%
国内特許登録補償	74.8%	72.0%	74.5%	94.4%	64.9%
海外特許出願補償	38.8%	24.1%	40.0%	61.1%	34.3%
海外特許登録補償	73.9%	72.0%	74.5%	88.9%	61.1%
その他産業財産権国内登録補償	55.3%	55.6%	58.2%	55.6%	38.0%
その他産業財産権海外登録補償	52.4%	55.6%	57.2%	50.0%	22.3%
自社実施補償	35.4%	24.1%	41.9%	16.7%	30.6%
他社実施補償	74.1%	73.7%	70.8%	94.4%	76.9%
処分補償	71.0%	73.7%	70.0%	94.4%	52.9%

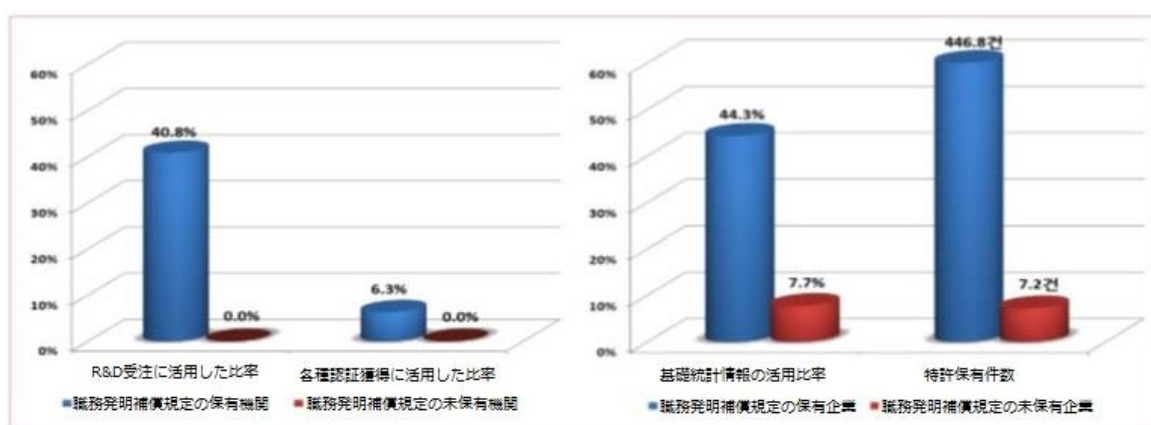
職務発明補償と関連する制度の効果と関連して職務発明に対する補償実施または補償水準の拡大が機関内発明件数及び品質向上と技術流出防止に効果的であると答えた比率が其々57.1%と44.5%となっている。

また、職務発明補償金に対する所得税非課税制度が発明件数及び品質向上と技術流出防止に効果的であると答えた比率は其々53.9%、44.2%を占めていることが分かった。

<職務発明補償規定の保有機関及び未保有機関における知的財産活動の比較>



職務発明補償規定を保有している機関が産業財産権を R&D 実施または各種認証の獲得に活用した比率を調査した結果、未保有機関に比べて極めて高いことが分かった。職務発明補償規定を保有している機関が産業財産権を R&D 実施及び認証の獲得に活用した比率は其々40.8%、6.3%であり、未保有機関の場合いずれも 0.0%である。また、職務発明保有機関の基礎統計情報を活用する比率と平均特許保有件数を調査した結果、未保有機関に比べて高いことが分かった。職務発明補償規定を保有している機関の場合、基礎統計情報の活用比率と平均特許保有件数は其々44.3%、446.8 件となっており、未保有機関の 7.7%、7.2 件に比べて比較的が高いことが確認できる([図 3.16])。

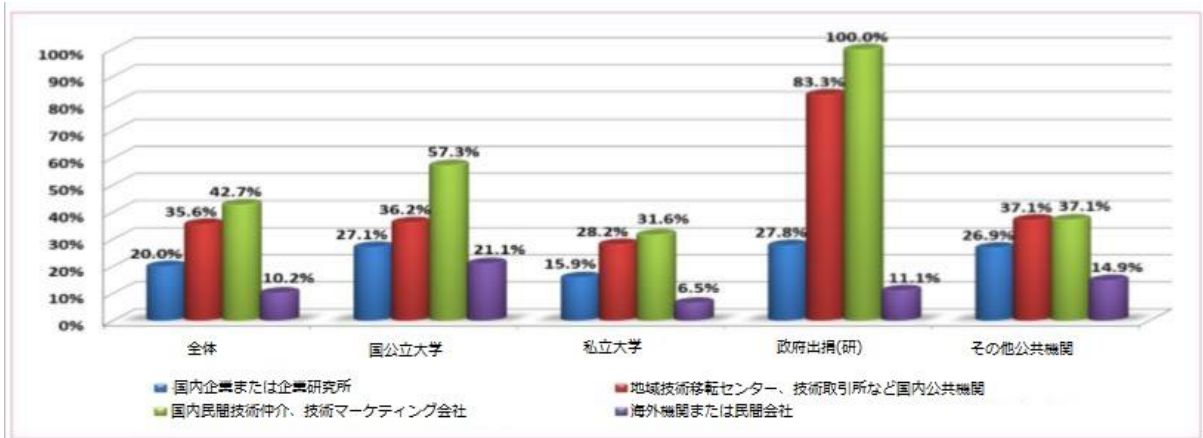


[図 3.16]職務発明補償規定の保有・未保有機関における産業財産権の活用比率

注：標本調査の結果

### 3. 技術取引機関、技術マーケティング会社との協力

最近 3 年間技術取引機関に業務を依頼した比率を見ると、大学及び公共(研)の場合平均 42.7%が国内民間技術仲介、技術マーケティング会社に業務を依頼したり、業務協約を締結していることが分かった。また、地域技術移転センター、技術取引所など国内公共機関に関連業務を依頼した比率は 35.6%となっている([図 3.17])。全ての機関類型において国内民間技術仲介、技術マーケティング会社に依頼する比率が最も高く、政府出捐(研)と国公立大学、その他公共機関、私立大学において其々100.0%、57.3%、31.6%であることが分かった。

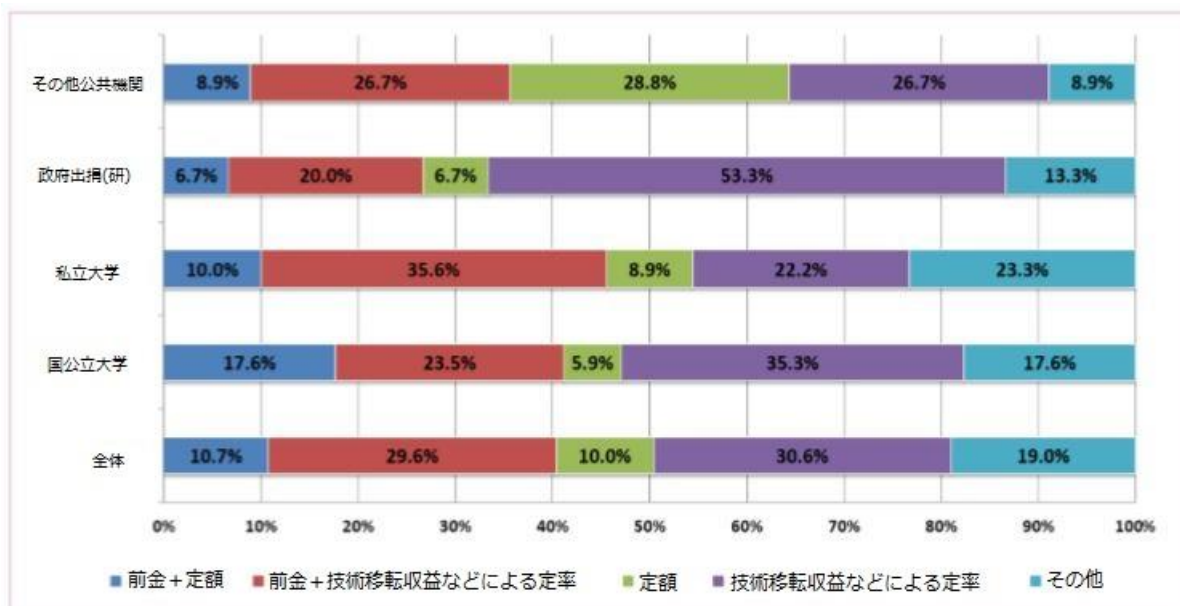


[図 3.17] 最近 3 年間技術取引機関への業務依頼及び締結の状況

注：複数回答

技術取引機関などに業務を依頼した場合の主な費用支給方法として、全体の 30.6% が技術移転収益などによる定率で計算した成功報酬と答えている([図 3.18])。特に、政府出捐(研)の 53.3% が該当費用支給方法を選択している。このような結果は、企業の場合このような費用支給方法を選択した比率が 14.6% と比較的に低いことを考えると、企業と大学・公共(研)間の技術移転取引の際に好む費用支給方法にかなり違いがあることを意味する。

その他に調査/マーケティング費用など活動費(前金)と技術移転収益などによる定率が結合した形態とその他方法を選択した比率が其々 29.6%、19.0% と続いている。



[図 3.18] 技術取引機関などに業務を依頼した場合の主な費用支給方法



[表 3.5]は国内技術取引システムに対する活用状況を示している。技術移転、取引のために IP-mart など国内オンライン技術取引システムを実際に活用している機関の比率は全体の 44.9%となっている。特に、政府出捐(研)及び国公立大学のオンライン取引システムの活用比率が其々88.9%と 51.2%と高いことが分かった。しかし、実際活用している機関のうち該当システムの活用度が高いと認識している比率は全体の 24.6%に止まっている。

また、技術移転及び取引のために特許技術移転博覧会など国内オフライン取引システムを活用している比率は 48.2%となっており、オンライン取引システムを活用する比率より若干高い数値となっている。また、実際活用している機関のうち該当システムの活用度が高いと答えた比率は 40.0%とオンラインシステムより高い結果となっている。

一方、yet2.com など海外オンライン取引システムを活用している比率は 19.8%、該当システムの活用度が高いと答えた比率は 2.6%と活用度そのものは低い水準であることが分かった。また、海外オフライン取引システムもまた活用比率は 17.6%であるが、活用度が高いと答えた比率は 0.0%となっている。

[表 3.5]国内技術取引システムの活用度

		全体	国公立 大学	私立 大学	政府 出捐(研)	その他 公共(研)
国内オンライン 取引システム	活用機関	44.9%	51.2%	36.7%	88.9%	45.4%
	活用度が比較的に高い	24.6%	29.4%	18.3%	37.5%	24.5%
国内オフライン 取引システム	活用機関	48.2%	54.3%	40.4%	94.4%	45.4%
	活用度が比較的に高い	40.0%	33.3%	39.4%	52.9%	32.7%
海外オンライン 取引システム	活用機関	19.8%	15.1%	17.5%	50.0%	14.9%
	活用度が比較的に高い	2.6%	0.0%	4.7%	0.0%	0.0%
海外オフライン	活用機関	17.6%	18.1%	12.6%	50.0%	18.6%

取引システム	活用度が比較的に高い	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
--------	------------	------	------	------	------	------

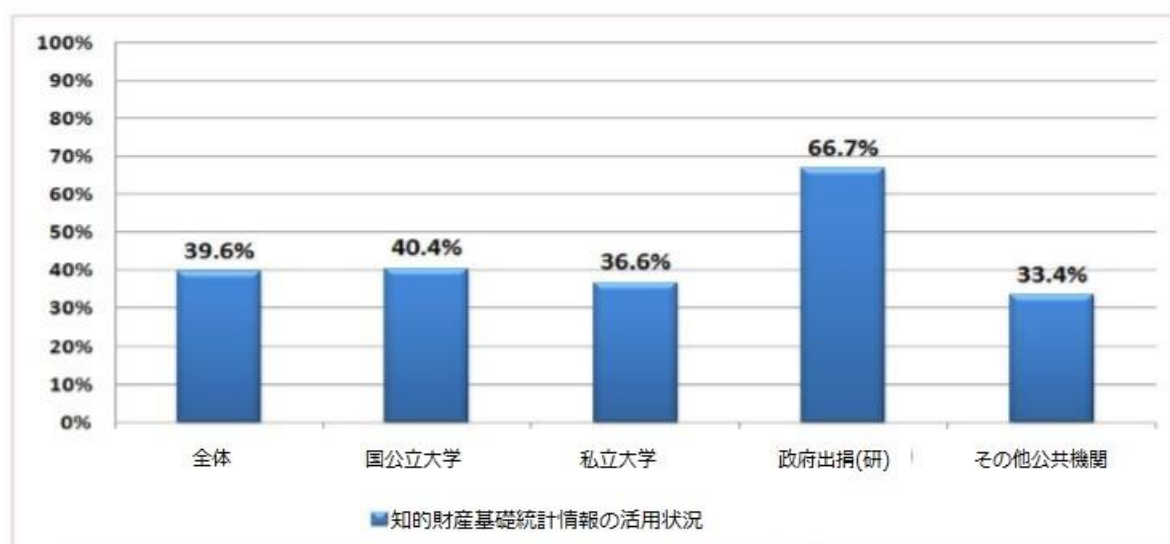
注. (%)は 5 点尺度(1:活用度が低い、5:活用度が高い)で[4 と 5 と答えた企業数]/(活用した経験のある企業数)]×100(%)、母集団推定値

### 第3節 知的財産の創出及び活用活動

#### 1. 知的財産基礎統計情報及び情報システム

大学及び公共(研)の場合、知的財産統計など基礎統計情報を活用している比率は全体の39.6%(40.7%)となっている。機関類型別で見ると、政府出捐(研)の活用比率が66.7%(同一)と最も高く、その後国公立大学、私立大学、その他公共機関と続いている([図 3.19])。

主に活用する統計指標として「特許登録件数」が回答者の75.8%(75.7%)となっており、「年度別出願件数」、「産業部門別の出願件数」が其々74.5%(74.4%)、11.8%(12.1%)となっている。「特許登録件数」及び「年度別の出願件数」の場合は政府出捐(研)が其々83.3%(同一)の比率で最も多く活用しており、その他公共研究機関が其々77.8%(同一)、私立大学が75.2%(74.7%)及び70.8%(70.4%)、国公立大学が70.1%(71.2%)及び77.6%(78.4%)と全ての機関類型において最も多く活用していることが分かった。

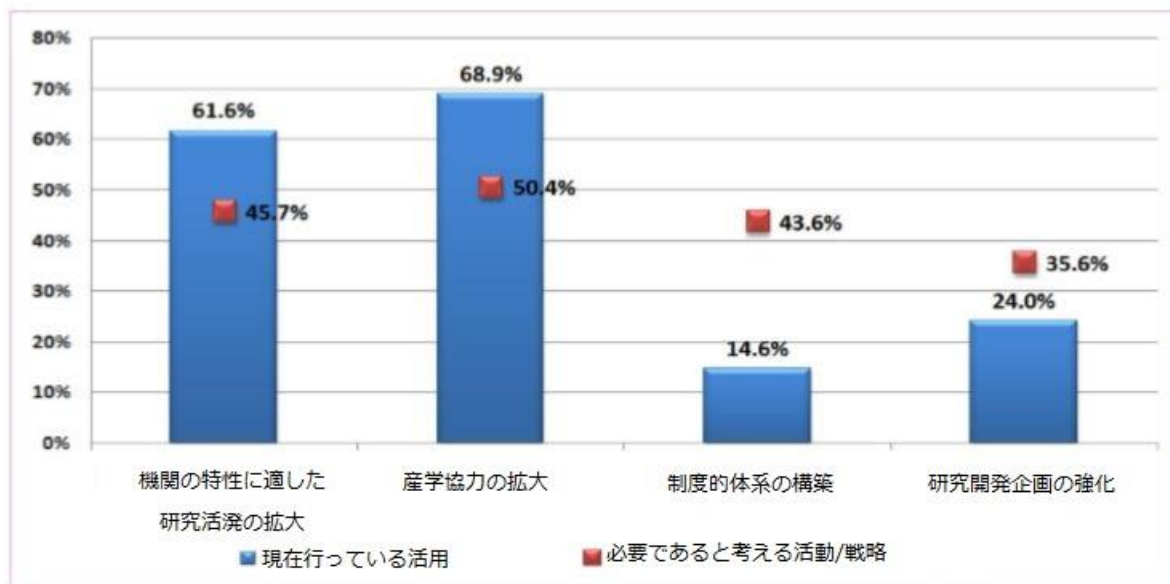


[図 3.19] 知的財産基礎統計情報の活用状況

## 2. 知的財産を創出するための研究開発活動及び今後の戦略

優秀な知的財産を創出するための戦略として、大学及び公共(研)の68.9%(69.8%)が産学研協力を通じた共同・委託研究開発を拡大していると答えている([図 3.15])。また、機関特性に適した研究開発課題を発掘して機関独自の研究開発投資を拡大していると答えた比率が61.6%(61.8%)と続いている。一方、優秀な知的財産を創出するための方法として研究開発企画の際に市場ニーズが反映できる制度的な体系を構築していると答えた比率は14.6%(15.0%)と最も低い。

機関類型別では、優秀な知的財産を創出するために私立大学及び国公立大学の場合産学研協力を通じた共同・委託研究開発の拡大に力を入れているという答えが其々74.3%(75.0%)、69.3%(72.9%)と最も多いが、その他公共機関と政府出捐(研)の場合は機関特性に適した研究開発課題を発掘し、機関独自の研究開発投資を拡大しているという回答が其々69.4%(同一)と83.3%(同一)と最も大きな比重を占めている。また、研究開発を企画する時に市場ニーズが反映できる制度的な体系を構築している比率は政府出捐(研)が33.3%(同一)と他機関類型に比べて高いことが分かった。



[図 3.20] 優秀な知的財産を創出するための活動及び戦略

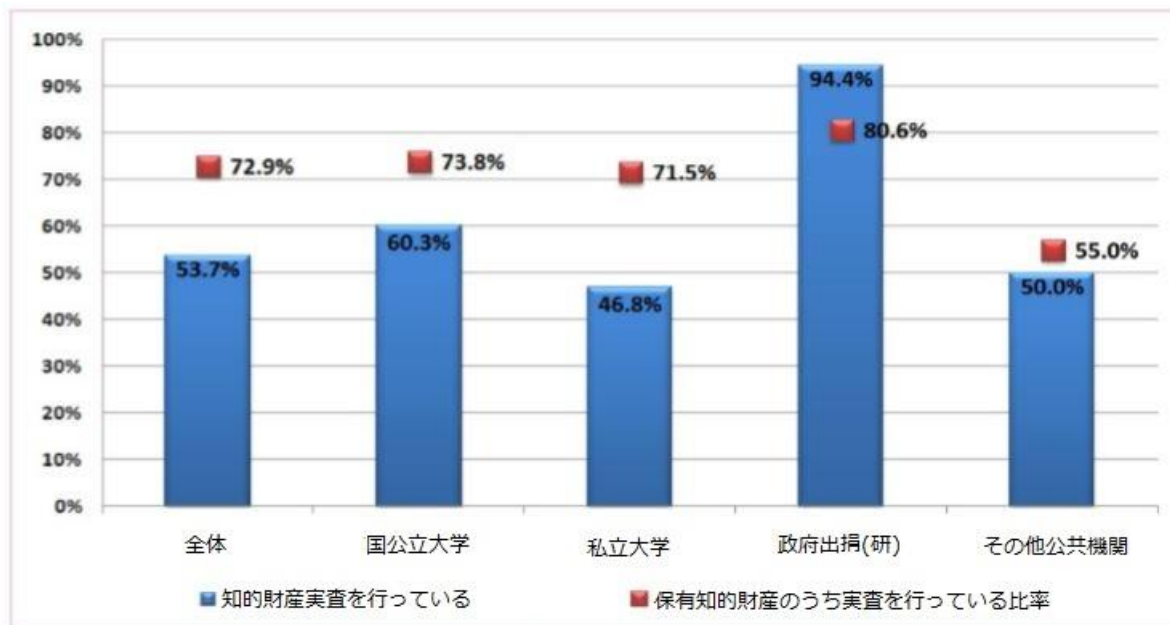
注. 複数回答

一方、現在の行っているかどうかは関係なく優秀な知的財産を創出するために必要と考える活動や戦略は産学研の協力を通じた共同/委託研究開発の拡大と答えた比率が 50.4% (49.5%) と最も高い。中大型、重要課題における優秀特許の創出に向けた研究開発企画の強化が必要と答えた比率は全体の 35.6% (36.3%) と最も低い。機関特性に適した研究開発課題の発掘及び独自研究開発の拡大、研究開発企画の際に市場ニーズが反映できる制度的な体系の構築に対しては全般的に同水準で必要性を認識していることが分かった。

特に、研究開発企画の際に市場ニーズが反映できる制度的な体系を構築する戦略と重要研究開発課題における優秀特許の創出に向けた研究開発企画強化戦略の場合は現在大学及び公共(研)が行っている比率より重要と認識している機関の比率がより高いことを考えると、今後強化あるいは支援が必要と見られる。

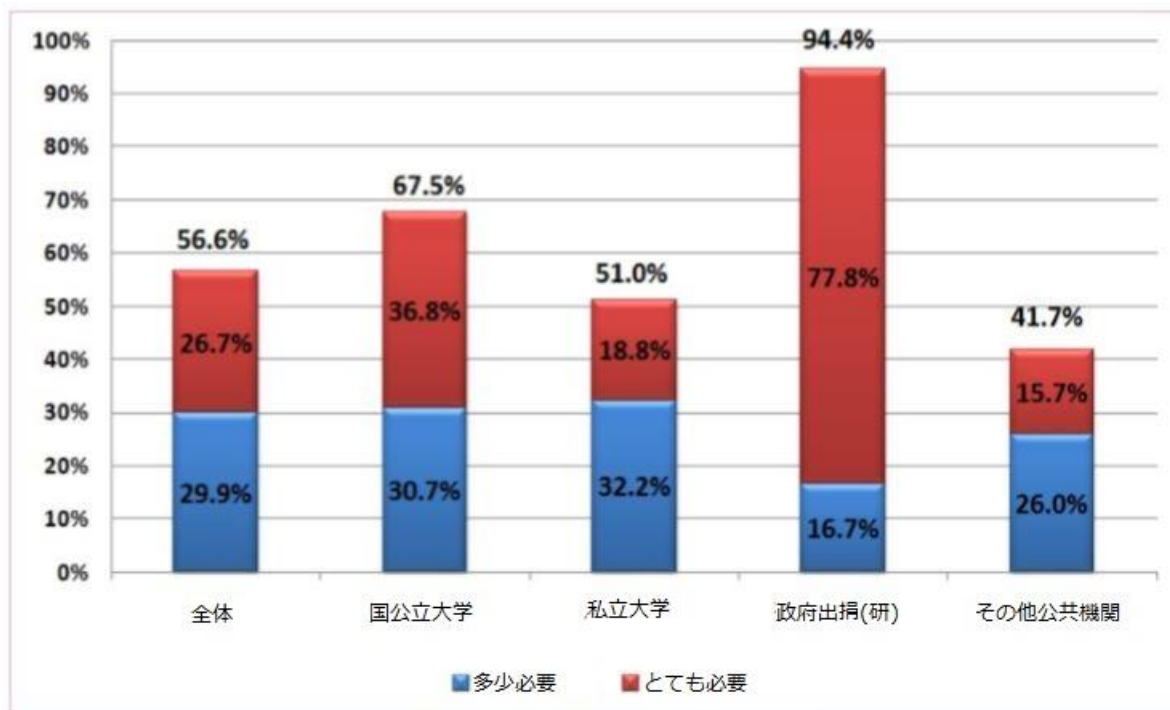
### 3. 保有知的財産の実査状況

保有知的財産に対する実査(評価)を行っている大学、公共(研)の比率は 53.7% (54.6%)、保有している知的財産のうち実査を行っている比率は 72.9% (72.8%) である([図 3.21])。機関類型別で見ると、政府出捐(研)の場合知的財産実査を行っている比率が 94.4% (同一) で最も高いが、保有知的財産のうち実査の実施比率は 80.6% (同一) と全体平均より若干高い水準である。一方、国公立大学の知的財産実査の実施比率は 60.3% (同一) となっているが、保有知的財産のうち実査実施比率は 73.8% (同一) と高い方であり、私立大学の場合にも実査実施比率は 46.8% (48.1%) 止まっているものの保有知的財産のうち実査実施比率は 71.5% (71.3%) と高い。



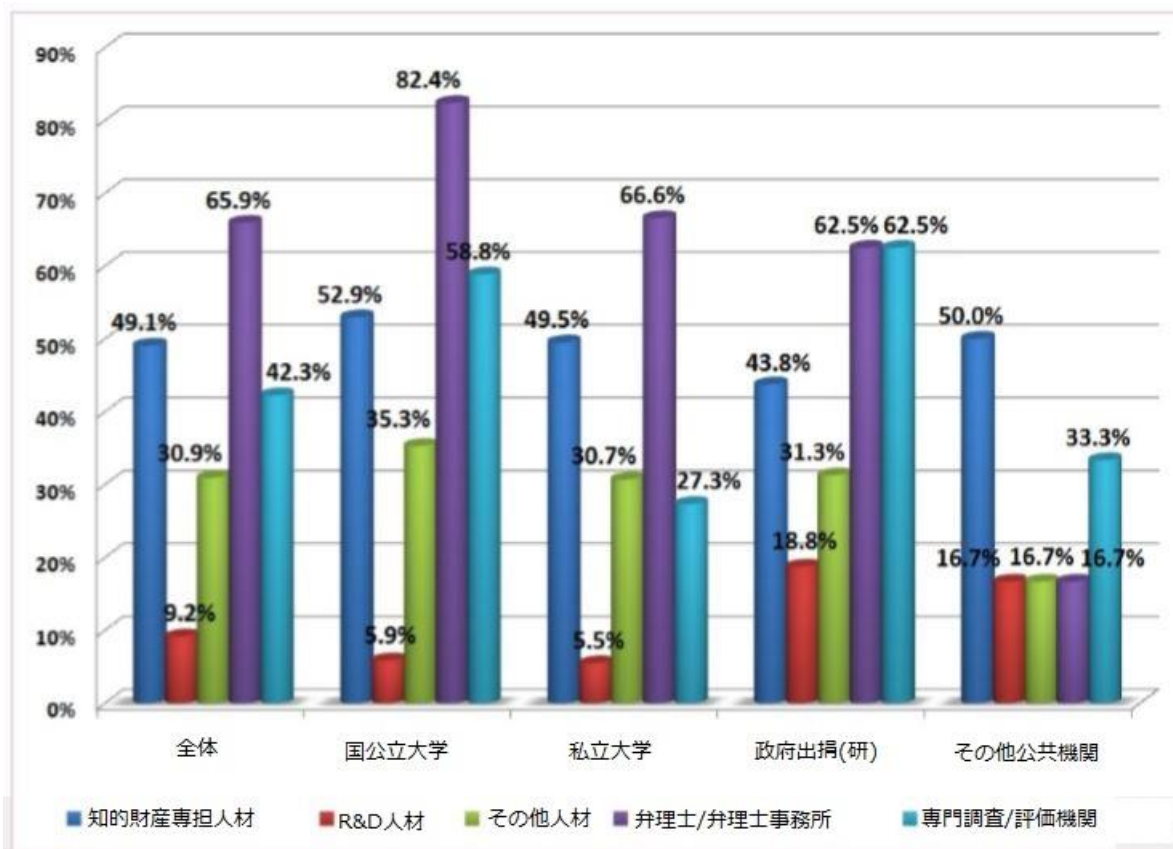
[図 3.21] 知的財産実査の実施状況

国内大学及び公共(研)の 56.6% (57.9%) は知的財産に対する実査が必要またはとても必要と答えている ([図 3.22])。これは実際行っている比率である 53.7% (54.6%) に比べて高い。知的財産実査の必要性に対して肯定的に回答した比率は政府出捐(研)と国公立大学が其々 94.4% (同一)、67.5% (68.9%) と高い。特に、政府出捐(研)の 77.8% (同一)、国公立大学の 36.8% (37.5%) が知的財産に対する実査がとても必要と答えている。



[図 3.22] 知的財産実査の必要性

一方、知的財産の実査を行っている場合、弁理士/弁理士事務所に依頼したり、知的財産専担人材が行っている場合は其々65.9%(同一)と49.1%(48.8%)と高く、専門調査/評価機関に依頼すると答えた比率も42.3%(41.9%)となっている([図 3.23])。これまで知的財産実査の場合主に外部人材が行うケースが多かったが、知的財産の専門性が増大したことで知的財産専担人材が行う比率が高い比率を占めている。最近では外部人材を活用すると同時に内部的な実査を実施することから知的財産実査に対する認識が根付いたことが分かる。



[図 3.23] 知的財産実査を行っている場合、その実施人材

注. 複数回答

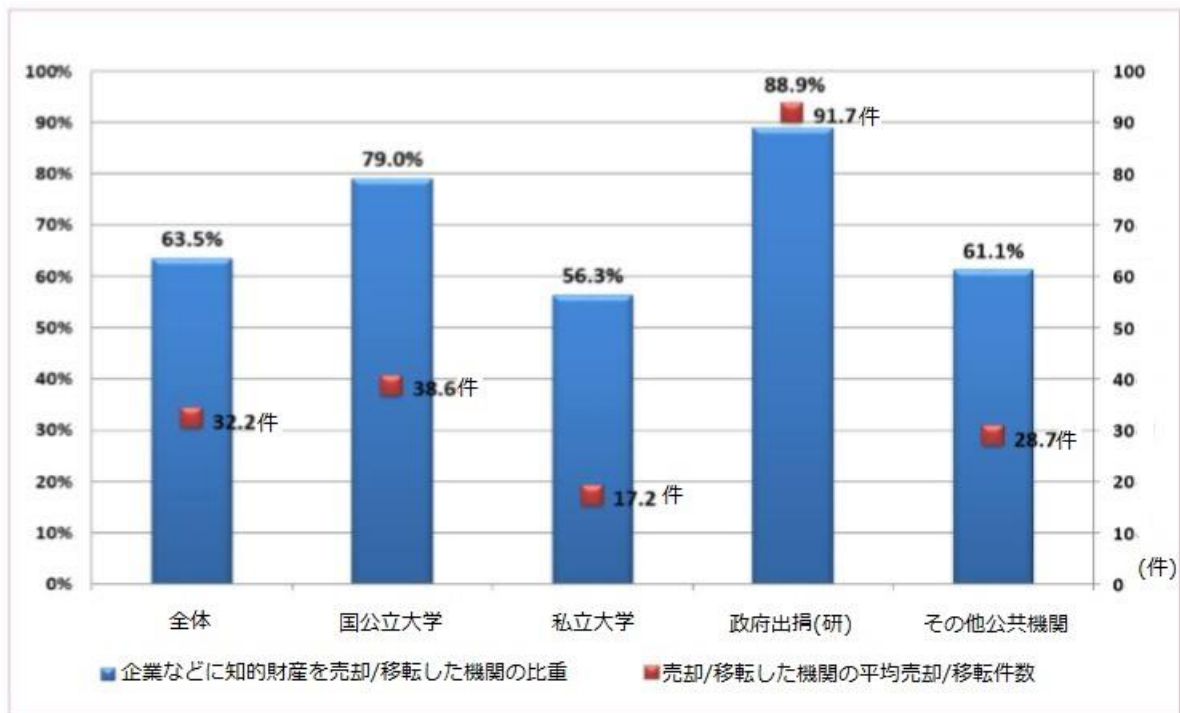
#### 4. 知的財産権の売却・移転及び活用状況

2013年の1年間1件以上の知的財産を企業などに売却または移転した大学及び公共(研)の比率は全体の63.5%(64.5%)となっており、知的財産を売却/移転した大学、公共(研)の平均売却/移転件数は32.2件(32.1件)<sup>46</sup>となっている([図 3.24])。

機関類型別では、政府出捐(研)の88.9%(同一)が平均91.7件(同一)の知的財産を売却/移転し、国公立大学の79.0%(79.7%)が平均38.6件(38.2件)の知的財産を売却/移転している。一方、海外に1件以上の知的財産を売却/移転した機関の比率は全体の4.3%(4.4%)となっている。

<sup>46</sup> 全体機関平均としては20.6件



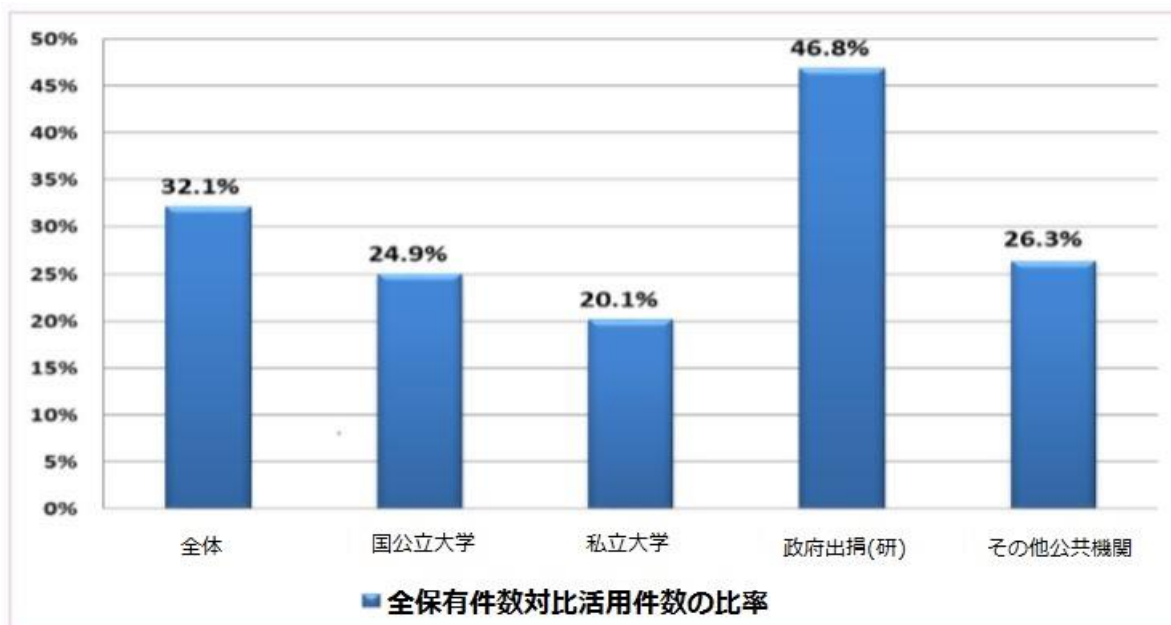


[図 3. 24] 知的財産を売却/移転した機関の比率及び件数

大学及び公共(研)が 2013 年産業財産権を有償実施許与または売却することで得た金銭的な成果は平均 5 億 2,300 万ウォン(5 億 2,994 万ウォン)となっている。機関類型別で見ると、政府出捐(研)の平均が 21 億 6,533 万ウォン(同一)で他機関に比べて極めて高い。また、ノウハウだけを実施許与したり、売却することで得た成果は平均 1 億 4,923 万ウォン(1 億 5,128 万ウォン)で、政府出捐(研)の平均は 6 億 2,894 万ウォン(同一)となっている。

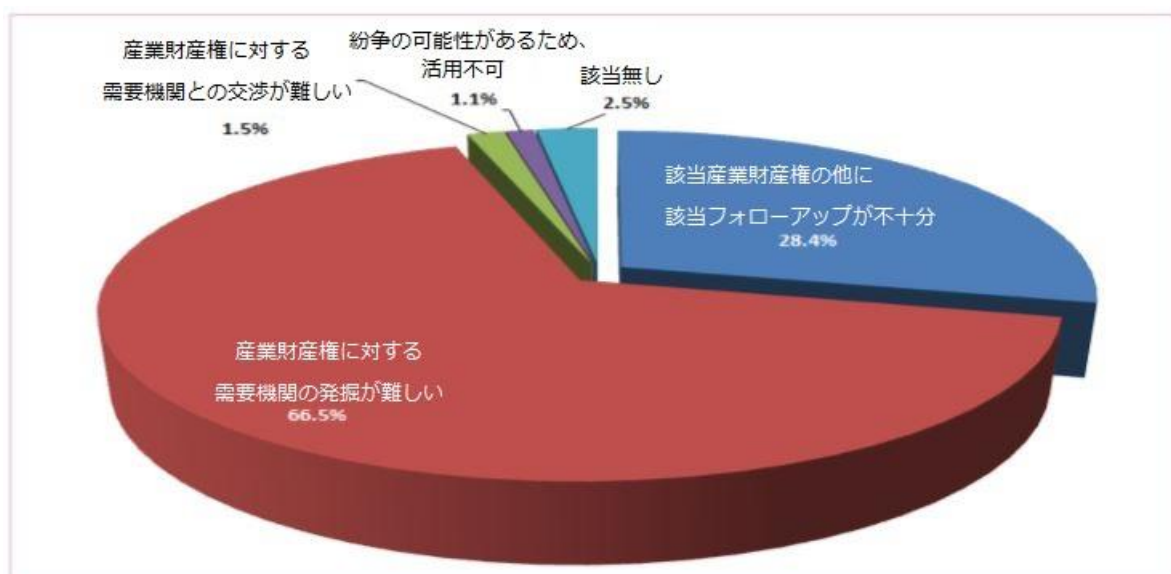
大学、公共(研)が保有する特許権のうち外部の他機関に移転されたり、実験室創業、研究員創業などに活用された活用件数の比率<sup>47</sup>は 32.1%(同一)となっている([図 3. 25])。特許の活用件数比率は政府出捐(研)、その他公共研究機関、国公立大学が其々 46.8%(同一)、26.3%(同一)、24.9%(同一)と続いている。私立大学の場合は 20.1%(同一)で最も低い。

<sup>47</sup> 企業の場合生産活動や技術移転などには直接活用していないが、戦略的な目的(核心技術の防御、特許訴訟防止、国家レベルでの必要性など)で保有・活用している特許が存在するため、これを反映して活用率と事業化率を区分するが、大学、公共研究機関の場合はこのような差が殆どないため活用率と事業化率を同じ意味で使うことにする。



[図 3.25] 特許権の総保有件数対比活用件数の比率

特許権の未活用理由として「産業財産権に対する需要機関の発掘が難しい」ことを指摘した比率が 66.5%で最も高く、「該当産業財産権の他にフォローアップが不十分」と答えた比率が 28.4%となっている。その他に「該当無し」の場合を除いた少数意見としては「産業財産権に対する需要機関との交渉が難しい」が 1.5%、「紛争の可能性のあるため、活用不可」が 1.1%となっている[図 3.26]。)



[図 3.26] 特許権未活用の理由

## 5. 効果的な知的財産の創出及び活用のために必要な政策支援

大学及び公共(研)の効果的な知的財産創出のために専門家の派遣、知財権コンサルティング事業の拡大など大学と公共研究機関の知的財産権創出活動の支援が必要と答えた比率は全体の 64.3% (66.2%) で最も高い([表 3.6])。特に、政府出捐(研)の 72.2% (同一)が必要と答えており、様々な政策支援の中で最も高い比重で必要と答えている。国公立大学の場合はは多様な技術分野に対する特許マップの構築支援が必要と答えた比率が 84.3% (87.9%) で最も高く、同時に研究者などを対象とする知的財産権関連教育支援もまた 78.3% (81.9%) の比率で最も必要と答えている。

[表 3.6] 効果的な知的財産創出のための政策支援の必要性

	全体	国公立 大学	私立 大学	政府 出捐(研)	その他 公共(研)
職務発明補償制度を導入したり、補償水準が拡大できるように支援	52.9%	66.8%	55.9%	22.2%	39.0%
特許情報活用拡散事業の拡大など先行特許調査と特許情報活用支援	61.4%	72.3%	60.7%	66.7%	43.2%
専門家の派遣、知財権コンサルティング事業の拡大など大学と公共研究機関の知的財産権創出活動の支援	64.3%	78.3%	59.4%	72.2%	65.3%
多様な技術分野に対する特許マップ構築支援	58.4%	84.3%	54.4%	61.1%	39.0%
研究者などを対象とする知的財産権関連教育支援	64.1%	78.3%	60.7%	66.7%	61.0%

注. (%)は 5 点尺度(1: 必要性が最も低い、5: 必要性が最も高い)で[(4 点と 5 点と答えた企業数)/(総回答機関数)]×100(%)

国内大学及び公共(研)の効果的な知的財産活用に向けた政策支援として技術移転関連のマーケティング及びコンサルティング支援が必要と答えた比率は全体の 78.4%

(79.6%)で最も高い([表 3.7])。保有特許技術に対する価値評価支援が必要と答えた比率も78.1%(79.3%)と続いている。

機関類型別では、技術移転関連のマーケティング及びコンサルティング支援が必要と答えた比率は国公立大学と政府出捐(研)、私立大学が其々94.0%(同一)と83.3%(同一)、76.0%(77.9%)となっており、保有特許技術に対する価値評価の支援が必要と答えた比率は国公立大学と政府出捐(研)、その他公共機関が其々84.9%(同一)と77.8%(同一)、76.9%(同一)と続いている。

[表 3.7]効果的な知的財産活用のための政策支援の必要性

	全体	国公立 大学	私立 大学	政府出 捐(研)	その他 公共 (研)
保有特許技術に対する価値評価支援	78.1%	84.9%	76.7%	77.8%	76.9%
新技術の事業化のための研究所企業 /実験室創業支援	60.8%	60.2%	63.7%	55.6%	49.1%
特許技術取引、流通システムの改善	70.1%	81.3%	65.9%	66.7%	80.6%
技術移転関連のマーケティング及び コンサルティング支援	78.4%	94.0%	76.0%	83.3%	64.9%
優秀技術の輸出支援	55.0%	57.2%	54.4%	61.1%	50.0%

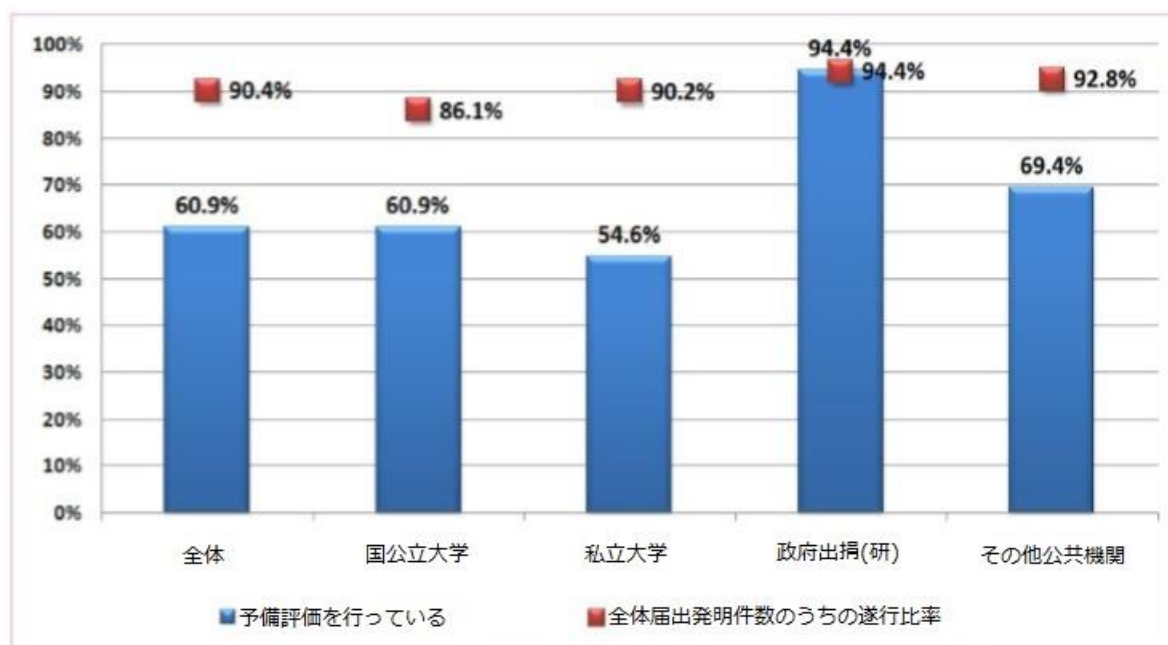
注：(%)は5点尺度(1：必要性が最も低い、5：必要性が最も高い)で[(4点と5点と答えた企業数)/(総回答機関数)]×100(%)

## 第4節 知的財産の保護

### 1. 予備評価実施状況

産業財産権の出願などに先立って機関内で予備評価を行っている大学及び公共(研)の比率は 60.9%(62.3%)となっている([図 3.27])。機関類型別で見ると、予備評価の実施比率が最も高い機関は政府出捐(研)で 94.4%(同一)に達していることが分かった。一方、予備評価を実施している比率が最も低い機関は私立大学で 54.6%(56.6%)に止まっている。

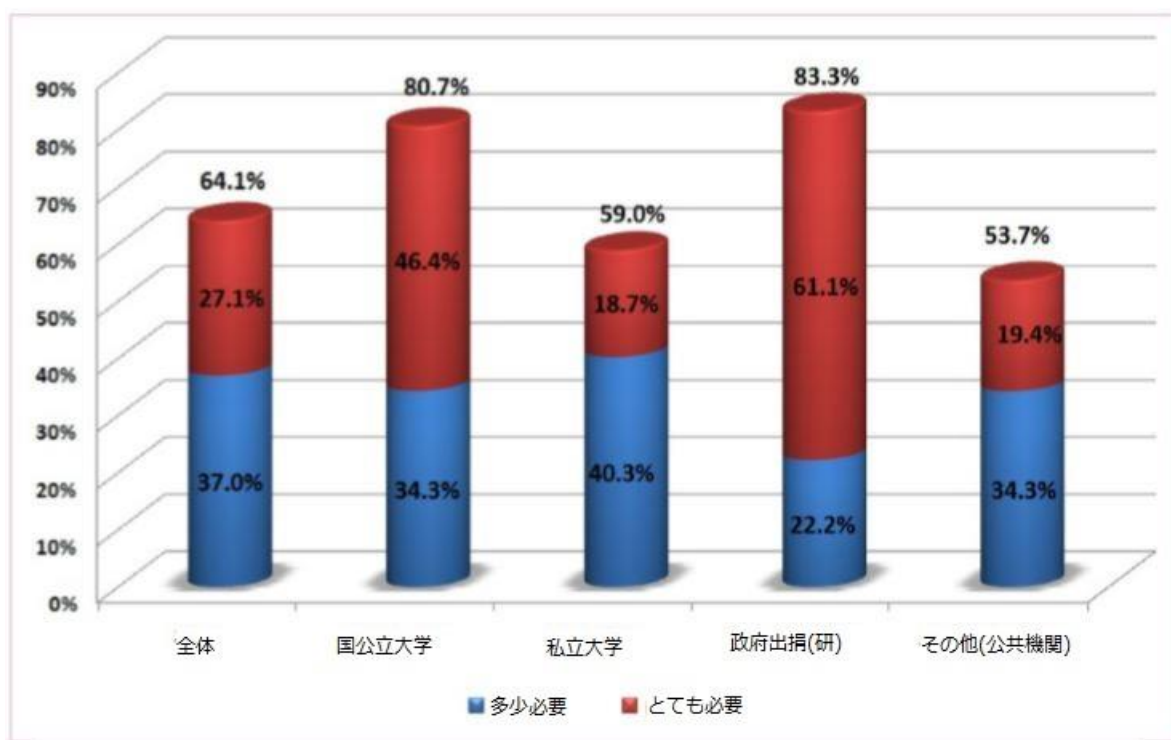
また、予備評価を実施する場合届出られた発明件数のうち平均 90.4%(90.5%)に対して実施していることが分かった。全体届け出られた発明件数全体のうち予備評価を行う比率は政府出捐(研)の場合 94.4%(同一)で最も高く、その他公共機関が 92.8%(同一)、私立大学が 90.2%(90.3%)と続いている。



[図 3.27] 産業財産権の出願などに先行して行う予備評価の実施状況

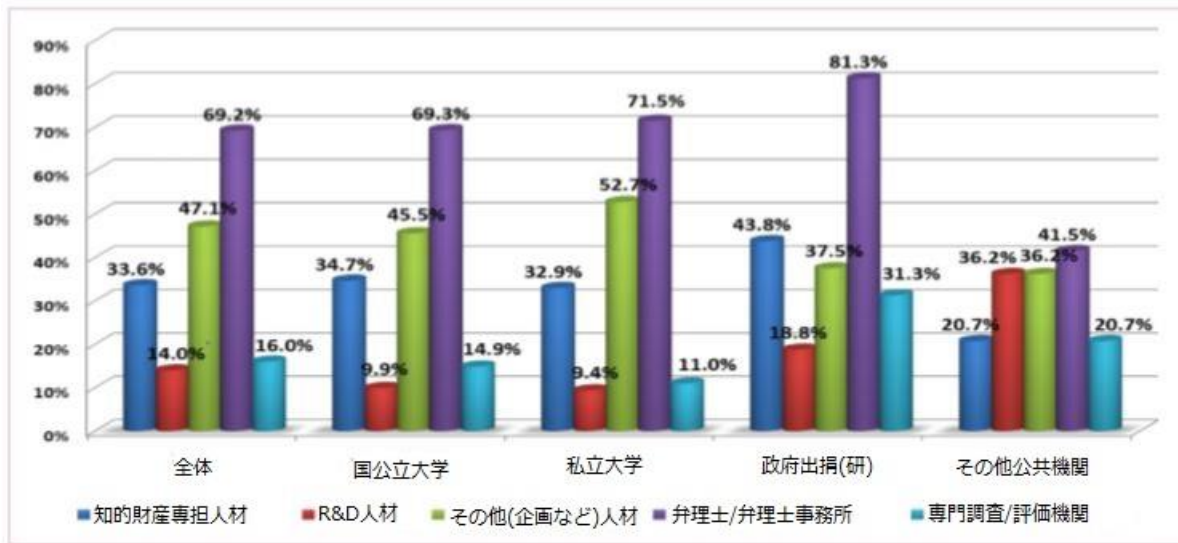
産業財産権を出願する前に予備評価を行う必要性に対しては[図 3.28]のように全体の 64.1% (64.9%)が必要またはとても必要と答えている。これは現在の実施比率である 60.9% (62.3%)に比べて高い数値であり、予備評価の必要性に対して認識はしているもののあらゆる事情によって実施出来ない機関が存在することを意味する。

機関類型別で見ると、予備評価が必要と答えた比率は政府出捐(研)の 83.3% (同一)が最も高い。特に、とても必要と答えた比率が 61.1% (同一)に達している。また、国公立大学の 80.7% (79.3%)が予備評価が必要と答え、とても必要と答えた比率は 46.4% (47.8%)となっている。



[図 3.28] 予備評価実施の必要性

一方、予備評価を実施していると答えた場合の 69.2% (68.6%)が弁理士/弁理士事務に該当業務を依頼すると答えている ([図 3.29])。その他(企画など)人材、知的財産専担人材、専門調査/評価機関が該当業務を行っている と答えた比率も其々 47.1% (47.9%)、33.6% (33.4%)、16.0% (15.9%)となっている。R&D 人材が行っている場合は全体の 14.0% (同一)に過ぎない。機関類型別では、知的財産専担人材が予備評価を実施している比率は政府出捐(研)が 43.8% (同一)と相対的に高い。

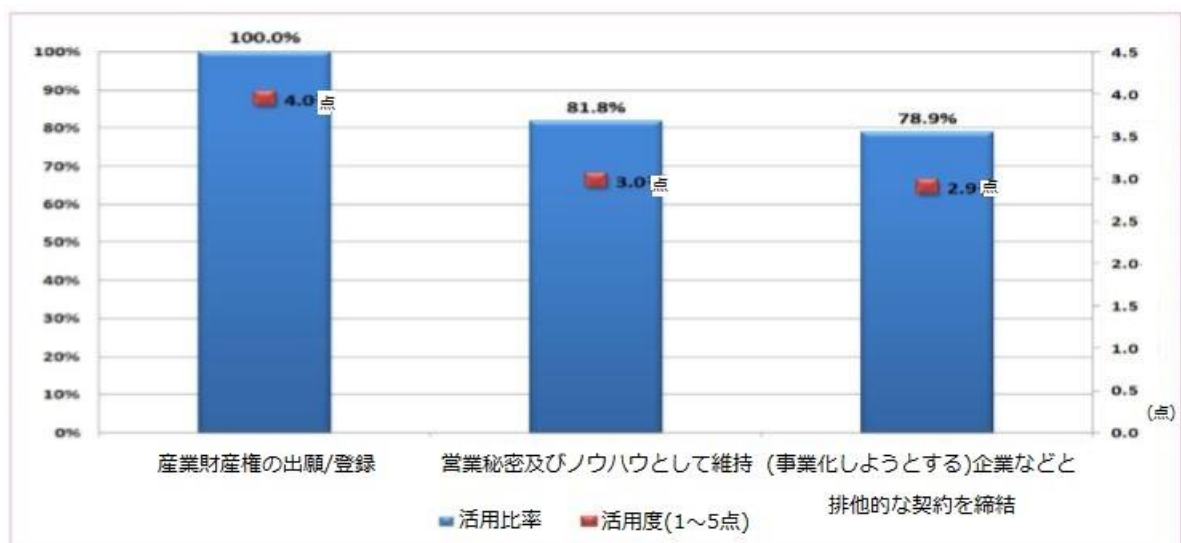


[図 3.29] 予備評価を実施している場合の実施人材

注：複数回答

## 2. 研究開発成果の保護戦略

研究開発活動の成果を保護するために活用する戦略として特許など産業財産権の出願を活用すると答えた比率は全体の 100.0% (同一) を占めている ([図 3.30])。また、機関内の営業秘密及びノウハウとして維持する戦略と事業化を図る企業などと排他的な契約を締結すると答えた比率も其々 81.8% (81.6%) と 78.9% (79.1%) に達している。

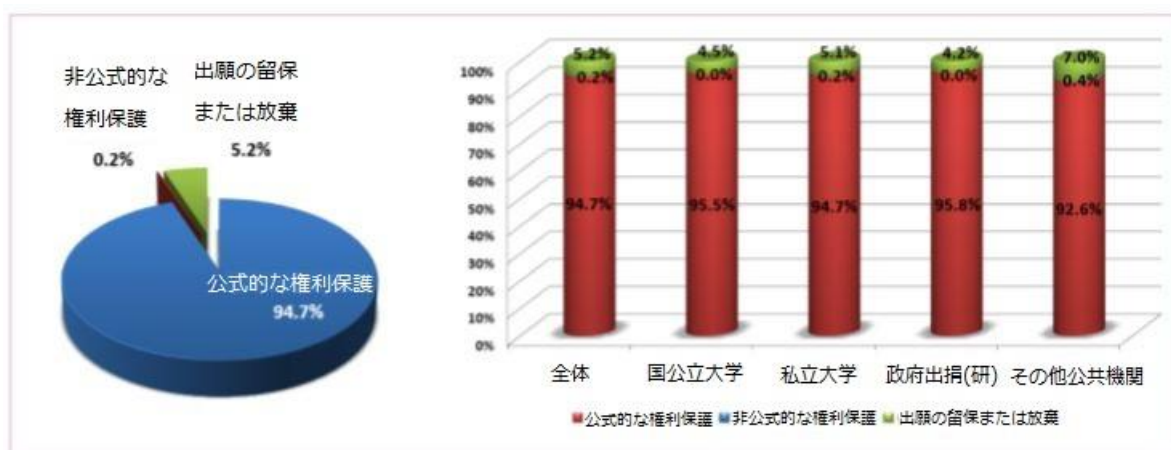


[図 3.30] 研究開発成果保護戦略の活用比率及び活用度



2013年1年間の発明届出件数は平均123.7件(125.5件)となっている。機関類型別では、政府出捐(研)が平均328.0件(同一)と最も多く、国公立大学、その他公共機関、私立大学が其々181.7件(181.8件)、121.3件(同一)、79.5件(81.5件)となっている。

このうち産業財産権の出願など公式的な権利保護手続きを踏んだ比率は[図3.31]のように、機関平均94.7%(94.6%)となっている。また、全体の5.2%(5.3%)が経済性、技術性の不足などの理由で出願を留保または放棄しており、非公式的な権利保護の比率は0.2%(同一)となっている。全ての機関類型において公式的な権利保護比率は高く、出願留保または放棄の比率も同水準を維持している。しかし、その他公共機関の場合他機関類型に比べて出願の留保または放棄の比率が7.0%(同一)と相対的に高い比重を占めている。



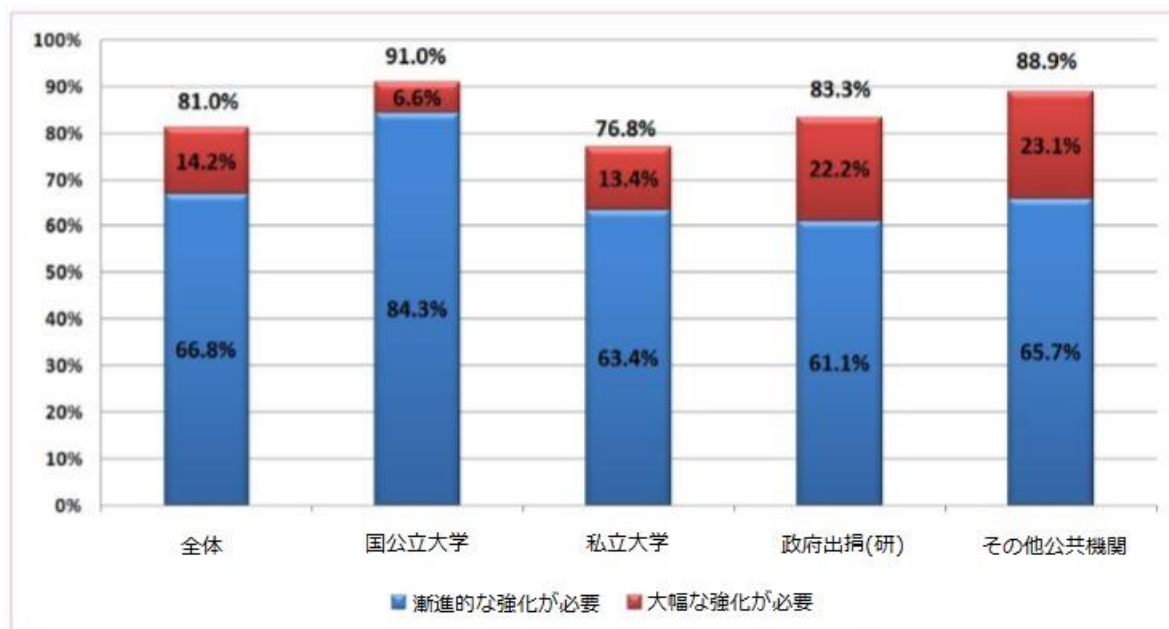
[図 3.31] 公式的/非公式的な権利保護の比率

現在国内知的財産の保護水準<sup>48</sup>と関連して今後更に強化する必要があると答えた比率が全体の81.0%(80.3%)となっている([図3.32])。特に、大幅な強化が必要であるという意見が全体の14.2%(同一)を占めている。機関類型別で見ると、国内知的財

<sup>48</sup> 知的財産の保護水準は特許制度のように創出された知的財産に権利を付与するシステムが効率的に運営されているかどうかと、これを通じて成立された知的財産権が他人によって侵害された時にそれに対抗できる効率的な行政的・司法的措置が如何に整えられているかを意味する。



産の保護水準を強化する必要があると答えた比率が国公立大学の場合 91.0% (同一) に達しており、一方私立大学の場合 76.8% (75.7%) と最も低い。



[図 3.32] 現在国内知的財産保護水準に対する認識

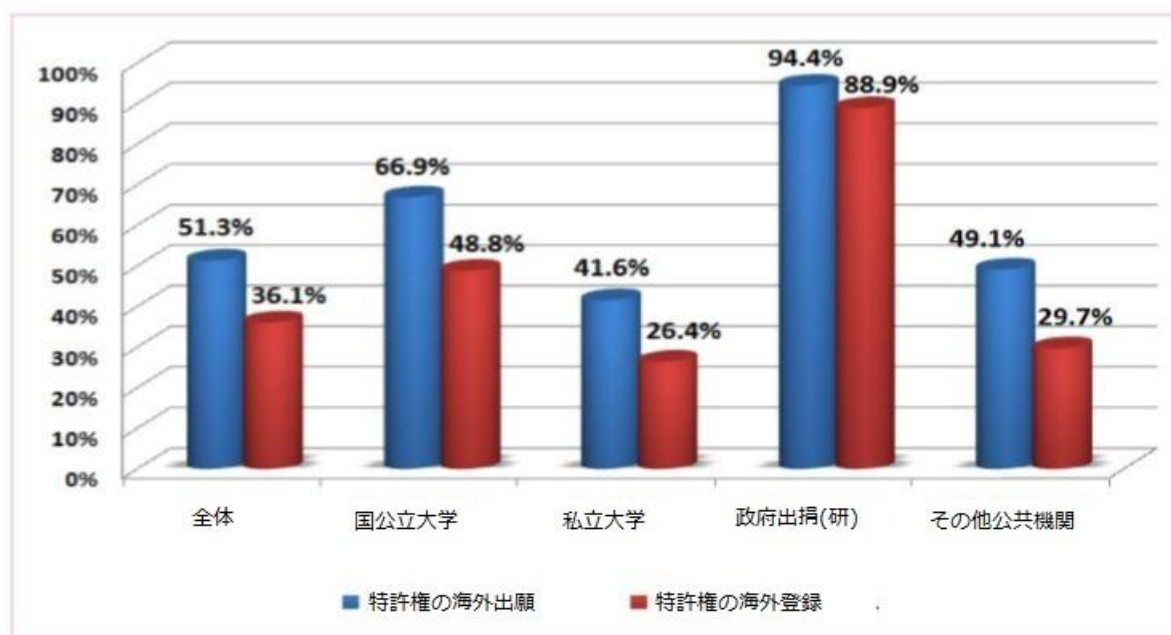
### 3. 産業財産権の海外出願/登録及び国内出願計画

国内大学、公共研究機関のうち 2013 年に 1 件以上の特許権を海外に出願 (PCT を含む) した機関は 51.3% (52.6%) となっている ([図 3.33])。また、1 件以上の特許権を個別国家に登録した機関は 36.1% (36.7%) を占めている。特許権の他にデザイン権と商標権を海外出願した比率は其々 0.9% (同一) と 0.0% (同一) となっている。政府出捐 (研) の場合特許権を海外に出願した比率が 94.4% (同一) と最高で、その他公共研究機関が 41.6% (43.2%) と最低となっている。

個別国家に出願された特許件数の全体機関平均は 20.7 件 (21.0 件)<sup>49</sup>、平均登録件数は 13.9 件 (14.1 件) となっている。機関類型別に出願された特許件数は政府出捐

<sup>49</sup> 同じ産業財産権を複数の国家に個別に出願または登録した場合はそれらを全て合算

(研)が 127.7 件(同一)、その他公共機関が 14.1 件(同一)、国公立大学が 13.7 件(同一)、私立大学が 8.3 件(8.5 件)である。また、平均 PCT 出願件数は 7.4 件(7.5 件)となっている。機関類型別では政府出捐(研)が 24.1 件(同一)、国公立大学が 11.6 件(11.7 件)、その他公共機関が 6.9 件(同一)、私立大学が 4.1 件(4.2 件)となっている。



[図 3.33]特許権の海外出願及び登録の比重

大学及び公共(研)の知的財産担当者が予想する 2014 年対比 2015 年の知的財産権国内出願と関連し、全体の 49.8% (49.2%) が特許権の出願を拡大すると答え、縮小すると答えた比率 5.3% (同一) に比べて極めて高い([表 3.8])。機関類型別では、私立大学が 53.6% (53.3%) で最も高く、その他公共機関が 31.4% (同一) で最も低い。また、政府出捐(研)は特許出願が縮小されると答えた比率が 16.7% (同一) と他機関類型に比べて若干高い。特許権の他の実用新案、デザイン、商標の出願を拡大すると答えた比率は其々 14.8% (14.4%)、17.0% (17.1%)、16.4% (16.7%) となっている。

[表 3.8]2014 年対比 2015 年の知的財産権出願計画

	全体	国公立大学	私立大学	政府出捐(研)	その他公共(研)

している。例えば、A という特許を米国、日本、ドイツに個別に出願または登録した場合、出願または登録件数は 3 と計算している。

特許	縮小	5.3%	3.0%	3.2%	16.7%	11.1%
	拡大	49.8%	47.0%	53.6%	50.0%	31.4%
実用新案	縮小	5.8%	18.1%	2.4%	5.6%	7.4%
	拡大	14.8%	12.6%	19.2%	5.6%	0.0%
デザイン	縮小	5.8%	15.1%	2.4%	11.1%	7.4%
	拡大	17.0%	12.1%	20.0%	5.6%	15.7%
商標	縮小	7.1%	21.7%	1.6%	11.1%	14.9%
	拡大	16.4%	18.7%	19.3%	11.1%	0.0%

国内出願の増減に影響を及ぼす要因として大学及び公共(研)全体の60.6%(61.7%)が産業財産権に対する成果評価の比重変化または評価方向の変化<sup>50</sup>と回答<sup>51</sup>している([表3.9])。また、研究開発投資または予算の増減による研究成果の変化と機関の産業財産権戦略の変化<sup>52</sup>を重要な要因と選択した比率は其々60.0%(62.6%)と54.5%(56.4%)と続いている。一方、国内及び世界の景気変動が影響を及ぼす要因が重要と選択した比率は25.4%(26.6%)に過ぎず、大体外部環境的な要因よりは機関内部的な要因が機関の出願件数の変化に与える影響がより大きいと言える。

[表3.9] 産業財産権の国内出願の増減に影響を及ぼす要因

影響を及ぼす要因	全体	国公立 大学	私立 大学	政府 出捐(研)	その他 公共機関
研究開発投資または予算の増減による研究成果の変化	60.0%	67.5%	64.0%	55.6%	29.7%
機関の産業財産権戦略の変化	54.5%	51.8%	52.8%	72.2%	53.7%
産業財産権に対する成果評価の比重変化 または評価方向の変化	60.6%	70.5%	58.9%	77.8%	41.7%

<sup>50</sup> 論文などその他成果対産業財産権実績の評価比重の拡大または縮小、量的成果評価の止揚及び質的成果評価の指向など

<sup>51</sup> 重要度において「高い」と「中間より高い」を選択した比率を比較する

<sup>52</sup> 量または品質中心の知的財産出願戦略、維持費用対収益性の変化など

市場及び技術競争環境の変化	44.8%	54.9%	43.6%	38.9%	41.7%
国内及び世界の景気変動	25.4%	30.7%	27.4%	27.8%	3.7%
産業財産権出願環境の改善及び支援制度の強化	52.9%	48.8%	57.9%	38.9%	41.7%

#### 4. 産業財産権の出願/審査/維持費用及び関連規定の状況

国内大学及び公共(研)は 2013 年の 1 年間知的財産の出願/審査/維持に平均 2 億 7,643 万ウォン(2 億 8,040 万ウォン)を支出していることが分かった([表 3.10])。機関類型別では、政府出捐(研)が 10 億 1,773 万ウォン(同一)と最も多く、国公立大学が 3 億 5,335 万ウォン(3 億 5,363 万ウォン)、その他公共機関が 3 億 3,916 万ウォン(同一)、私立大学が 1 億 4,308 万ウォン(1 億 4,644 万ウォン)を支出している。政府出捐(研)の場合は他機関類型とは異なり、国内出願/審査費用より海外出願/審査費用をより多く支出していることが分かる。

[表 3.10] 知的財産の出願・審査・維持費用

	国内		海外		出願・審査・維持費用の合計
	出願・審査	維持	出願・審査	維持費用	
全体	1 億 1,185 万ウォン	6,042 万ウォン	8,464 万ウォン	1,952 万ウォン	2 億 7,643 万ウォン
国公立 大学	1 億 5,016 万ウォン	1 億 213 万ウォン	7,835 万ウォン	2,270 万ウォン	3 億 5,335 万ウォン
私立大学	6,441 万ウォン	3,400 万ウォン	3,619 万ウォン	848 万ウォン	1 億 4,308 万ウォン
政府 出捐(研)	3 億 4,133 万ウォン	1 億 3,333 万ウォン	4 億 6,465 万ウォン	7,841 万ウォン	10 億 1,773 万ウォン
その他 公共機関	1 億 4,081 万ウォン	9,341 万ウォン	7,235 万ウォン	3,260 万ウォン	3 億 3,916 万ウォン

## 5. 効果的な知的財産保護のために必要な政策支援

国内大学及び公共(研)は効果的に知的財産を保護するため「出願前または出願後の知的財産評価費用の支援」と「産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免」が必要と答えた比率が其々76.6%(77.1%)と73.8%(74.1%)と高い([表 3.11])。特に、「企業などとの共同・委託研究契約の際に不平等契約防止のためのガイドラインの制定及び広報」が必要と答えた比率は国公立大学の場合77.7%(80.6%)で、他の機関と違って企業との研究契約を締結する際に直面する困難が相対的に大きいことを意味する。「出願前または出願後の知的財産評価費用の支援」が必要と答えた比率は政府出捐(研)と国公立大学、私立大学の場合其々88.9%(同一)と81.3%(84.9%)、77.6%(77.5%)とその他公共機関に比べて比較的に高い。

[表 3.11]効果的な知的財産保護のための政策支援の必要性

	全体	国公立 大学	私立 大学	政府 出捐(研)	その他 公共(研)
産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免	73.8%	68.1%	76.9%	77.8%	61.1%
海外出願関連情報の提供	50.4%	62.6%	49.3%	55.6%	34.3%
企業などとの共同・委託研究契約の際、不平等契約防止のためのガイドラインの制定及び広報	66.9%	77.7%	67.0%	50.0%	64.9%
出願前または出願後の知的財産評価費用の支援	76.6%	81.3%	77.6%	88.9%	53.7%

注. (%)は5点尺度(1:必要性が最も低い、5:必要性が最も高い)で[(4点と5点と答えた企業数)/(総回答機関数)]×100(%)

## 第5節 知的財産の侵害及び紛争

### 1. 知的財産権の侵害及び事後対応

母集団に属する 230 の大学及び公共(研)のうち 2.7%に該当する 6 つの機関<sup>53</sup>が 2013 年に知的財産権の侵害を受けたと答えている。<sup>54</sup>全体侵害事例は全て特許権侵害であることが分かった。

侵害機関の事例 6 件のうち侵害製品の製造者が海外企業である場合は 52.1%、国内企業である場合は 47.9%となっている。侵害製品の製造地域は国内 47.9%、米国 37.3%、中国 33.5%、その他 18.6%となっている。侵害製品の流通地域は国内 47.9%、米国 37.3%、中国 14.8%となっている。また、侵害製品の流通類型は 52.1%がインターネット及び通販などを通じたオンライン流通で、オフライン流通は 66.5%となっている。侵害機関の事例 6 件のうち民事訴訟を通じて損害賠償額が認められたり当事者間で和解が成立した場合は 1 件で、損害賠償額または和解金が 20～30 億ウォン未満と答えている。

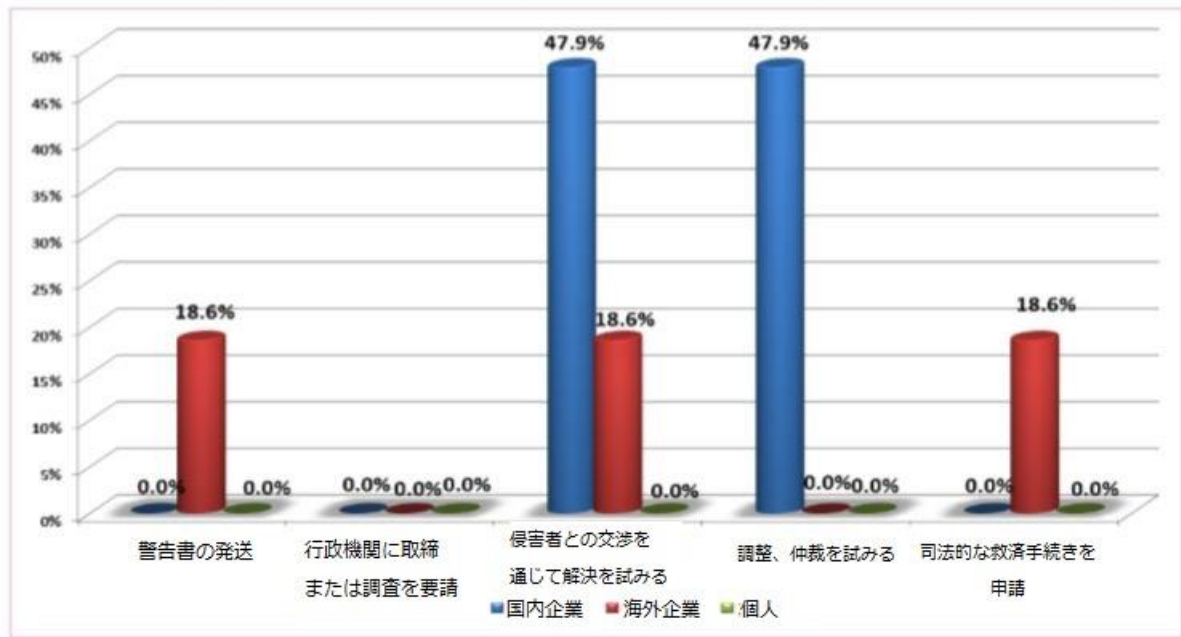
知的財産権侵害以後の事後対応として、知的財産権の侵害を受けた 6 つの機関のうち国内企業に警告書を発送した場合は全体の 0.0%、海外企業に警告書を発送した場合は 18.6%となっている。また、国内企業に対して侵害者との交渉を通じて解決を図った場合及び調停、仲裁を図った場合は其々 47.9%となっている([図 3.34])。一方、警告書の発送から侵害訴訟の完了時までにかかった費用<sup>55</sup>は平均 200 万ウォンである。

---

<sup>53</sup> 政府出捐(研)の2機関、その他公共機関の4機関

<sup>54</sup> 大学及び公共(研)の知的財産権侵害調査はこれまで殆ど行われたことがない。また、知的財産権の侵害による営業上の被害がないため実際に侵害された比率より知的財産管理担当者が認知している比率が極めて少ないことを考慮する必要がある。

<sup>55</sup> 損害賠償額または和解金額を除く。



[図 3.34] 知的財産権侵害の事後対応

## 2. 知的財産権侵害及び紛争関連の問題及び必要な政策支援

知的財産権侵害の対応における問題として、紛争対応関連の政府支援政策の不足または関連情報の不足、紛争対応の際に過剰な時間と費用がかかること、知的財産保護のための行政的・しほうてきな救済手続きの不備が最も大きな問題として指摘されている([表 3.12])。また、知的財産権法規など関連事項に対する情報の不足、内部人材の専門性不足にによる関連知識の習得が難しいこと、紛争対応のための法律代理人の選定が難しいことも問題として挙げられた。

[表 3.12] 知的財産権侵害の対応における問題

	程度が高い
知的財産権法規など関連事項に対する情報の不足	49.8%
内部人材の専門性不足によって関連知識の習得が難しい	49.8%
紛争対応関連の政府支援政策の不足または関連情報の不足	100.0%
紛争対応の際に法律代理人の選定が難しい	49.8%

紛争対応の際に過剰な時間と費用がかかる	100.0%
知的財産権保護のための行政的・司法的な救済手続きの不備	100.0%

注：(%)は5点尺度(1：必要性が最も低い、5：必要性が最も高い)で[(4点と5点と答えた企業数)/(総回答機関数)]×100(%)

最後に、知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策として、国内大学及び公共(研)の31.5%が侵害及び知的財産権有効性判断機関の一元化がとても必要と答え、最も高いことが分かった。また、知的財産権侵害対応のための訴訟など費用支援と知的財産権の保護及び対応活動のための情報提供がとても必要と答えた比率が30.3%、28.2と高い。

[表 3.13] 知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策

政府政策	とても必要
実効性のある行政的・司法的処罰措置の強化	25.2%
国境措置対象の知的財産権範囲の拡大、侵害物品の国内流入のシャットアウト	19.2%
知的財産権の保護及び対応活動のための情報提供	28.2%
行政機関の知的財産権侵害製品の取締権限の強化	27.0%
知的財産権侵害製品などに対する通報褒賞金額の増額	19.5%
知的財産権侵害対応のための訴訟など費用支援	30.3%
侵害及び知的財産権有効性判断機関の一元化(例：特許裁判所)	31.5%



## 第4章 2014年韓国知的財産活動 の年度別傾向

1. 知的財産担当組織及び人材保有比率の改善
2. 知的財産先行活動の変化
3. 外部からの知的財産導入の改善
4. 知的財産の活用及び事業化の比率増加
5. 知的財産保護戦略の変化
6. 知的財産権侵害類型の特徴

## 第4章 2014年韓国知的財産活動の年度別傾向

本章では知的財産活動の主要項目別・年度別の比較を通じて、国内企業及び大学・公共(研)の知的財産インフラ、特許基盤知的財産活動、創出及び活用、保護、侵害及び紛争の段階別活動がどのような方向に変化しているかを示している。また、2014年の既存母集団の結果を算出して比較しやすくしている。

### 1. 知的財産担当組織及び人材保有比率の改善

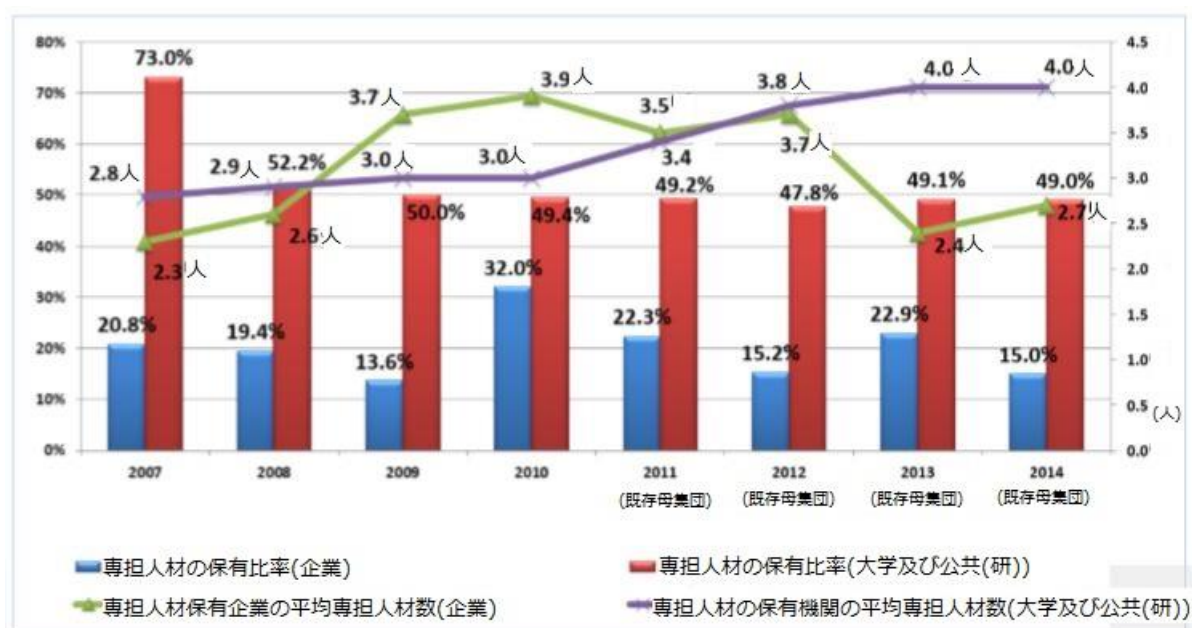
知的財産を担当する組織を保有している比率の推移は[図 4.1]のとおりである。企業の場合は知的財産担当組織の保有比率が2009年から着実に増加傾向にある。大学及び公共(研)の場合は2010年まで減少したが、2011年調査では大きく増加し、2013年以後同水準を維持している。企業の知的財産管理に対する認識の向上は知的財産担当組織及び人材の運営に影響を与えたと判断できる。



[図 4.1] 知的財産担当組織保有比率の推移

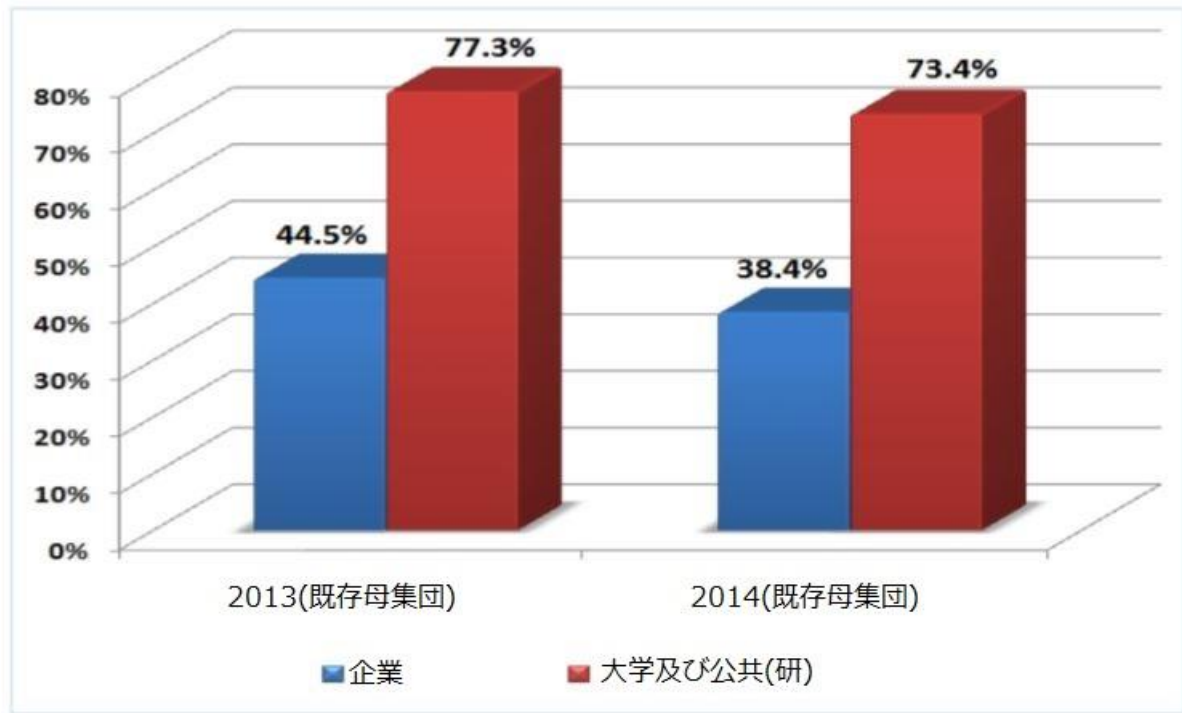
知的財産関連業務だけを専門的に行う専担人材を保有している企業と大学及び公共(研)の比率は2013年対比2014年に其々22.9%、49.1%から15.0%、49.0%に減少している。しかし、専担人材を保有している企業の平均専担人材数の場合2013年2.4人から2014年2.7人に増加し、大学及び公共(研)の場合は2014年4.0人と去年と同

じであることが分かった([図 4.2])。全体企業の平均専担人材数は多少減少したが、一方専担人材を保有している企業の平均専担人材数は増加したということは知的財産管理にインフラを既に整えている企業が知的財産インフラの強化により力を入れていることを物語っている。



[図 4.2] 専担人材の保有比率及び専担人材数の推移

知的財産担当人材を対象に職務教育を実施している比率は企業の場合 2013 年 44.5%から 2014 年 38.4%に減少し、大学及び公共(研)の場合も 77.3%から 73.4%に小幅減少している([図 4.3])。希望する職務教育の内容としては企業が「特許制度」と答えた比率が 51.4%で前年比増加し、「特許情報検索」に対する教育要請比率も 45.6%と前年比増加した。大学及び公共(研)の場合もまた「特許制度」、「特許情報検索」に対する教育要請比率がいずれも前年比増加した。企業と大学及び公共(研)はいずれも基礎的かつ幅広い知的財産関連の職務教育を必要としていることが分かる。



[図 4.3] 知的財産担当人材職務教育の実施状況

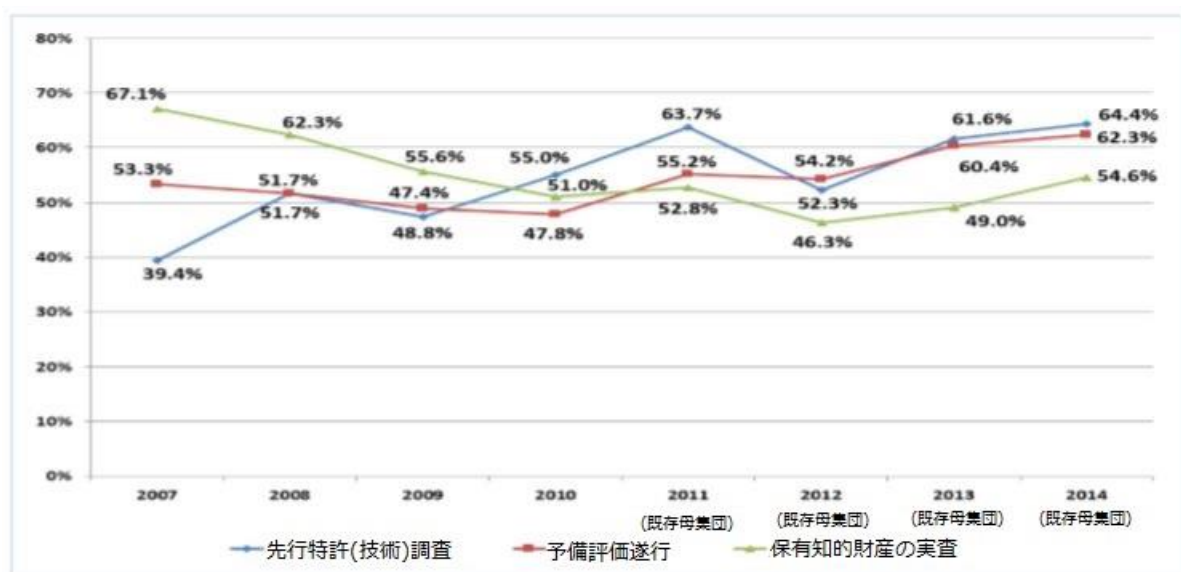
## 2. 知的財産先行活動の変化

先行特許(技術)調査、出願前の予備評価、保有知的財産に対する実査など特許先行活動を行っているとした企業の比率を年度別に見ると[図 4.4]のとおりである。まず、先行特許(技術)調査を行っている比率は 2013 年 72.9%から 2014 年 74.2%に増加し、保有知的財産実査比率は 2013 年 35.4%から 2014 年 36.0%に小幅増加している。但し、企業の予備評価を実施していると子与えた比率は 2013 年 38.7%から 2014 年 36.6%に小幅減少している。知的財産に対する紛争、訴訟が増加している状況によって知的財産を創出し、創出された知的財産を保護・活用する全ての過程を企画段階から戦略的に進めることで先行活動を強化しているものと見られる。



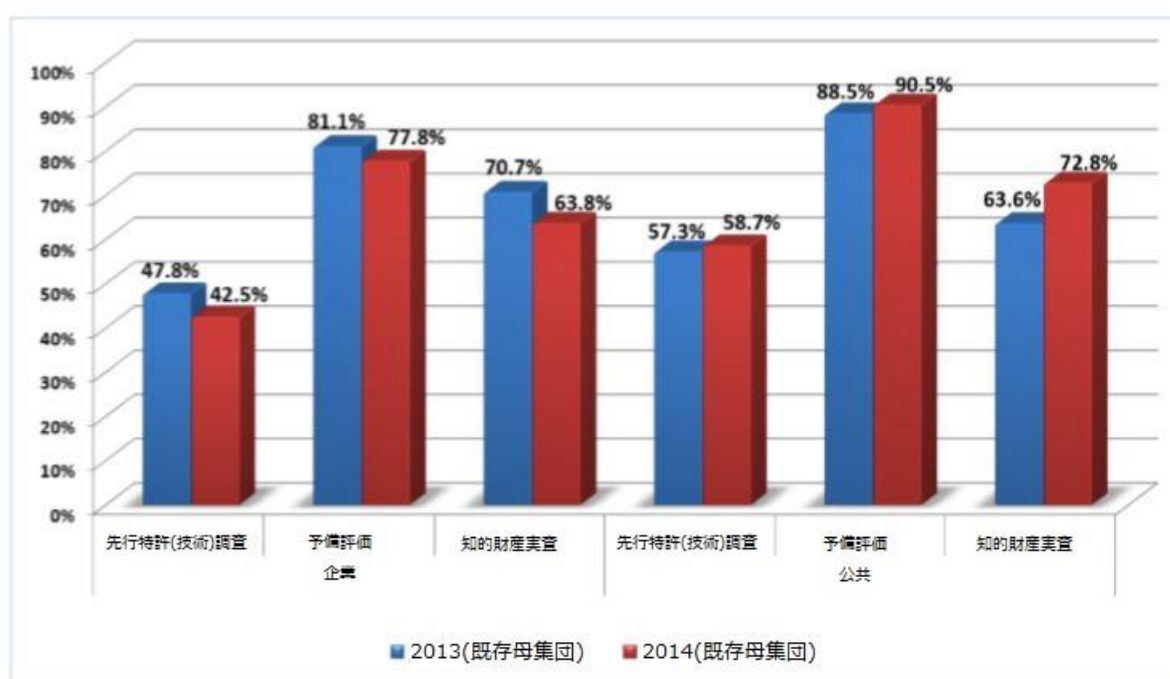
[図 4.4] 企業の先行活動実施比率の推移

大学及び公共(研)の場合には先行活動実施比率が 2013 年に比べていずれも増加している。先行特許(技術)調査実施比率の場合は 2013 年 61.6%から 2014 年 64.4%に増加し、保有知的財産実査の場合は 2013 年 49.0%から 2014 年 54.6%へと増加傾向にある。予備評価の場合にも 2013 年 60.4%から 2014 年 62.3%に増加している([図 4.5])。大学及び公共(研)の先行活動実施比率は 2012 年以後着実に増加傾向にあり、公共の場合は発明者本人だけでなく機関レベルで積極的に介入して先行活動を行う場合が増加しているものと見られる。



[図 4.5] 大学及び公共(研)の先行活動実施比率の推移

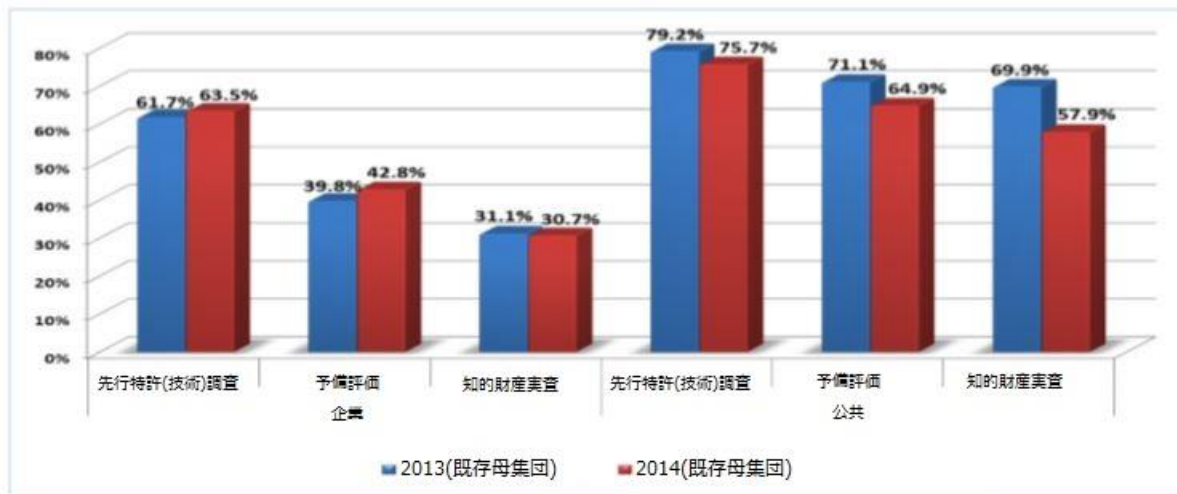
次に、全体研究開発課題において先行特許(技術)調査を行っている比率、全体発明件数のうち出願前に予備評価を実施する比率、保有知的財産のうち実査を行っている比率の年度別推移は[図 4.6]のとおりである。図からも分かるように、2014年調査で企業の場合各実施比率は2013年に比べていずれも減少しており、大学・公共(研)は各実施比率が2013年に比べていずれも増加している。



[図 4.6] 全体研究開発課題、発明、保有知的財産のうち実施比率の変化

各先行活動が必要と認識している国内企業、大学・公共(研)の比率は[図 4.7]のとおりである。企業の場合知的財産に関する先行活動の必要性認識度は2013年に比べて類似もしくは増加している。特に予備評価と関連する活動の場合、企業の比率は2014年に多少減少しているが、このような活動に対する必要性は増加していることが分かった。これは費用や時間がかかるなどの問題で実際活動を行う比率は減少しているとしても、最近特許紛争の増加、知的財産価値の増加などによって必要性に対する認識は高まっていると解釈できる。特に企業の場合予備評価や実査実施の必要性に比べて先行特許(技術)調査活動の必要性を高く評価しているが、これは企業が知的財産活動において初期創出段階から戦略的な側面を重視していることと関連があると見られる。





[図 4.7] 先行活動の必要性に対する認識の変化

### 3. 外部からの知的財産導入の改善

1 年間企業外部から知的財産を導入した企業の比率は[図 4.8]のとおりである。図からも分かるように、2009 年から国内から知的財産を導入した企業の比率は減少傾向にあったが、2014 年には増加に転じている。しかし、一方で海外から知的財産を導入した企業の比重は 2013 年に比べて 2014 年には小幅減少となっている。また、国内及び海外からの平均導入件数は国内から導入した平均件数が 0.6 件、海外から導入した平均件数が 0.1 件と 2013 年と同水準であることが分かった。



[図 4.8] 知的財産導入の推移

知的財産の導入を拡大すると答えた企業が導入を希望する技術の出处と関連した年度別の推移は[図 4.9]のとおりである。このうち、国内企業から知的財産を導入すると答えた比率は 2013 年 35.7%から 2014 年 47.8%に増加した。また、海外企業から知的財産を導入すると答えた比率は 2013 年 30.4%から 2014 年 43.5%に増加している。国内の大学及び研究機関、海外の大学及び研究機関から知的財産を導入すると答えた比率は其々2013 年 62.4%、12.0%から 2014 年 65.1%、15.3%へといずれも増加した。海外企業から知的財産を導入すると答えた比率は 2012 年以後持続的に増加傾向にあることが分かる。



[図 4.9] 知的財産導入拡大方向の変化

#### 4. 知的財産の活用及び事業化比率の増加

回答した全ての企業が保有している特許を合算し、その中で活用されている比率と事業化されている比率は[図 4.10]のとおりである。図からも分かるように、企業の特許活用率は 2014 年 81.0%と前年度の 76.1%に比べて増加し、事業化率もまた 2014



年 63.4%と前年度の 57.1%に比べて増加している。また、大学及び公共研究機関の場合も全ての機関が保有している特許対比活用比率が 2014 年 32.1%で前年度の 29.4%に比べて増加している。

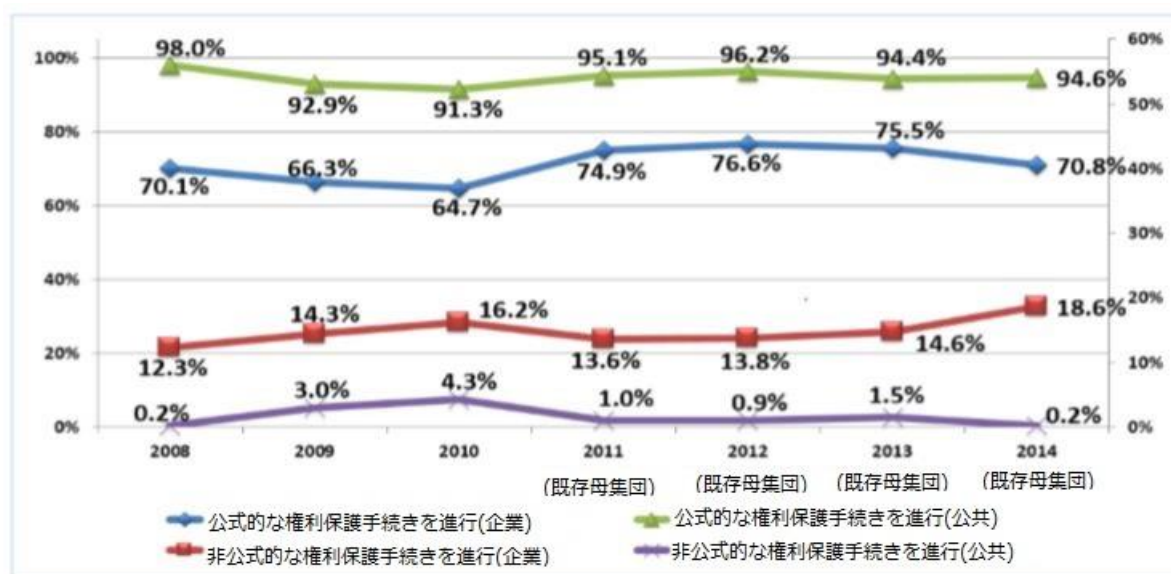


[図 4.10] 全体特許保有件数対比の活用率及び事業化率

## 5. 知的財産保護戦略の変化

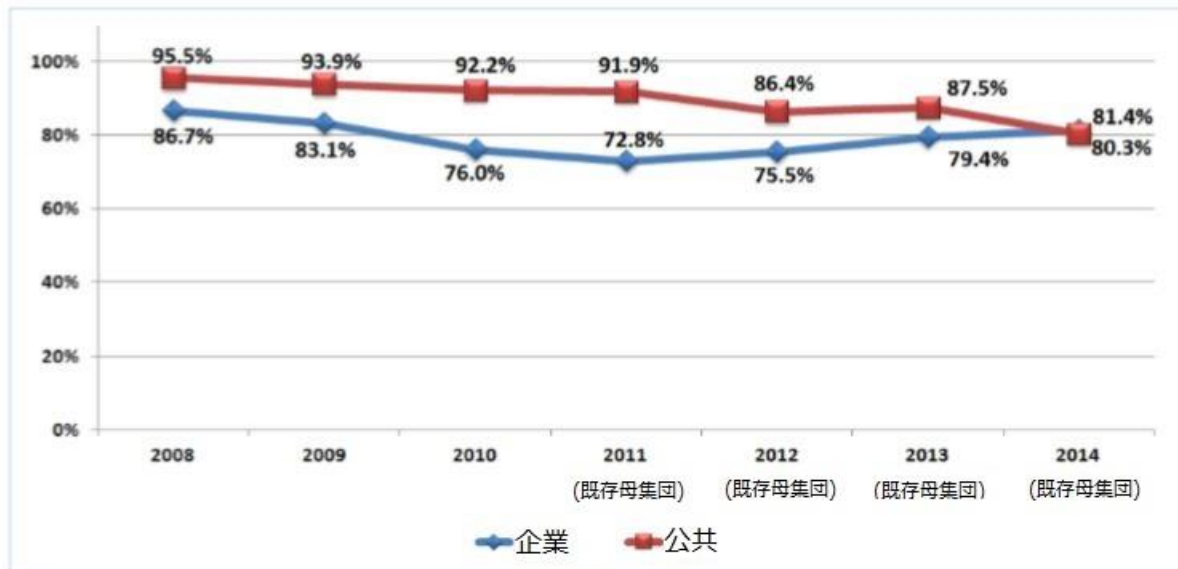
研究開発の成果を保護するための戦略として産業財産権の出願など公式的な権利保護手続きをする比率、非公式的な保護手続きをする比率の推移は[図 4.11]のとおりである。企業の場合公式的な権利保護手続きをする比率は 2013 年 75.5%から 2014 年 70.8%へと多少減少している。しかし、非公式的な保護手続きをする比率の場合は 2013 年 14.6%から 2014 年 18.6%へと増加している。大学及び公共研究機関の場合は公式的な権利保護手続きをする比率が 2013 年 94.4%から 2014 年 94.6%へと小幅増加したが、一方非公式的な保護手続きをする比率は 2013 年 1.5%から 2014 年 0.2%へと減少したことが分かった。大学及び公共研究機関の場合殆どの権利を出願などの公式的な権利保護手続きを通じて保護しており、そのような傾向が続いているものと

見られる。権利保護に対して公式的な権利保護手続きをしたり、非公式的な保護手続きをする活動に対しては企業と大学・公共(研)の立場に多少の違いが見られる。侵害及び紛争などに関連して企業の場合産業財産権の出願など公式的な手続きをある程度進めるが、営業秘密またはノウハウとして維持するなど非公式的な保護手続きの必要性を感じているものと見られる。



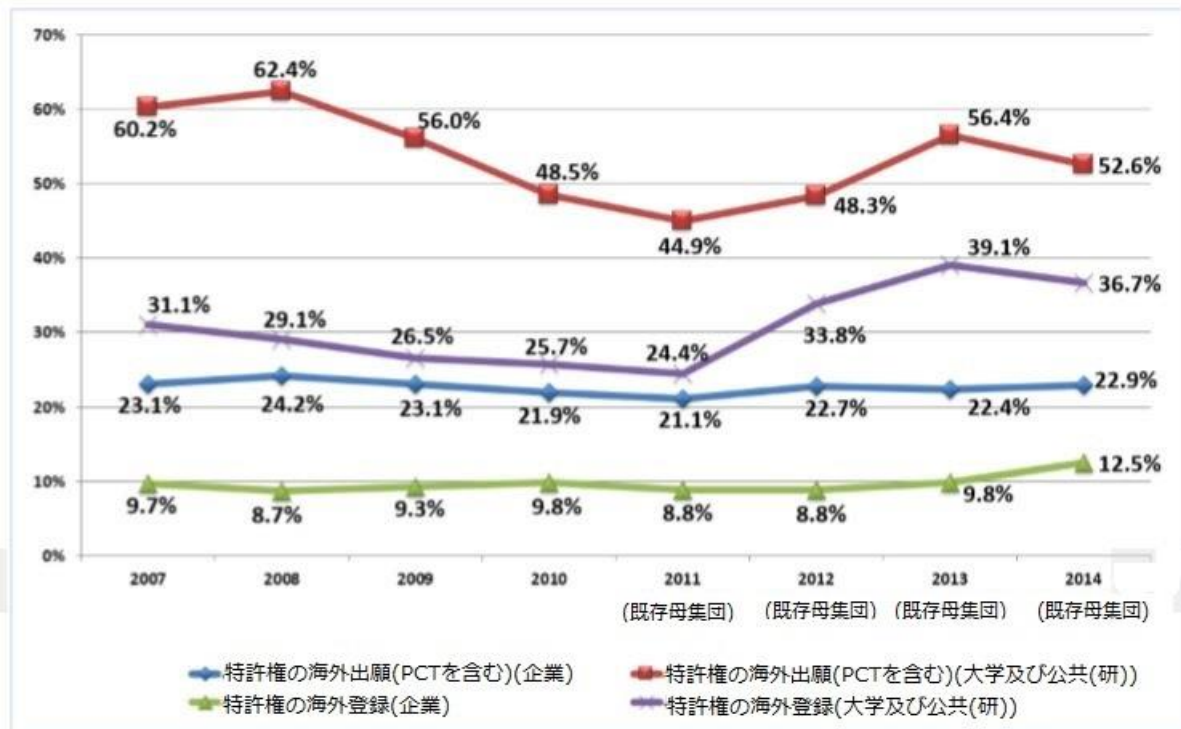
[図 4.11] 権利保護手続きの進行比率

国内の知的財産保護水準を強化する必要と答えた企業と大学・公共(研)の比率は[図 4.12]のとおりである。図からも分かるように、企業の場合知的財産保護水準の強化必要性が2011年から徐々に増加しているが、特に2014年には81.4%と2013年の79.4%に比べて更に増加している。一方、大学・公共(研)の場合その比率が小幅減少している。企業の場合国内外の関連 이슈が持続的に取り上げられたことから知的財産保護に対する必要性は認知しているものと判断できる。



[図 4.12] 国内知的財産保護水準強化の必要性

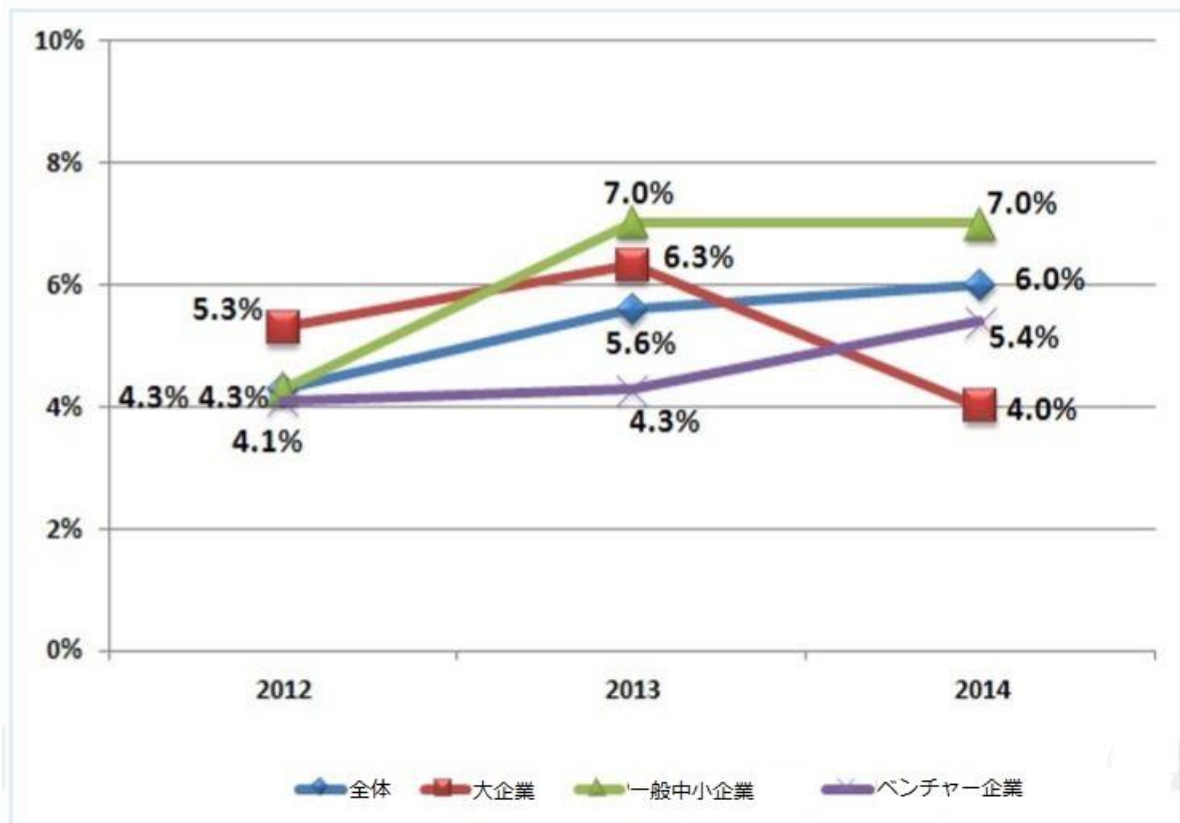
2013年の1年間海外に特許出願及び登録をした企業、大学・公共(研)の比率推移は[図 4.13]のとおりである。企業の海外出願及び登録の比率は2013年に比べて2014年に全て増加したが、大学・公共(研)の海外出願及び登録の比率は多少減少している。特に、企業の場合は国際的に企業間紛争が増加していることから海外での権利確保に向けた活動に関心を寄せているものと見られる。



[図 4.13] 海外出願及び登録の推移

## 6. 知的財産権侵害類型の特徴

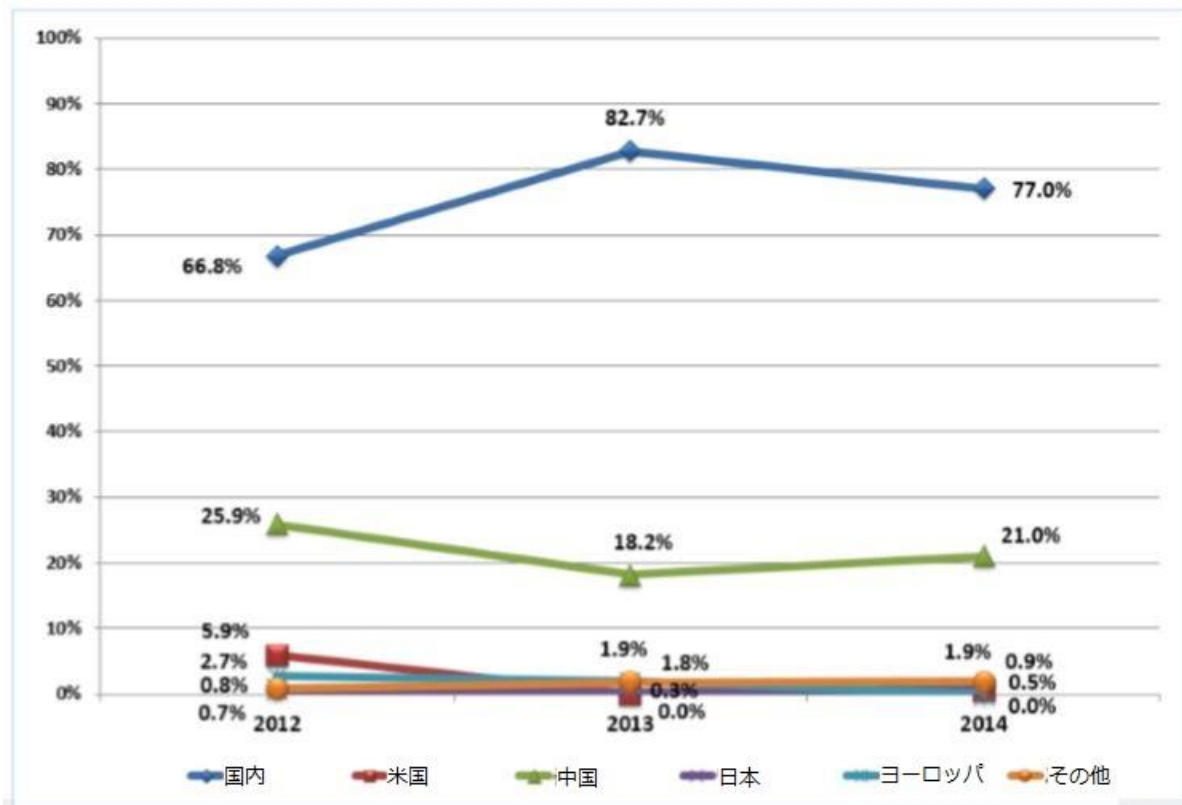
知的財産権の侵害を受けた企業の3ヵ年年度別傾向を見ると全体的に徐々に増加する傾向にある([図 4.14])。全体侵害比率は2012年4.3%から2013年5.6%、2014年6.0%と着実に増加しており、特にベンチャー企業の知的財産権侵害比率は2012年以後増加傾向にある。



[図 4.14] 知的財産権の侵害比率

知的財産の価値増加、侵害に対する認識向上によって侵害比率もまた増加しているものと見られ、特に技術を基盤とするベンチャー企業の侵害被害が増加しているため、知的財産インフラが相対的に弱い小規模の企業に対する改善方策及び環境の改善が求められている。

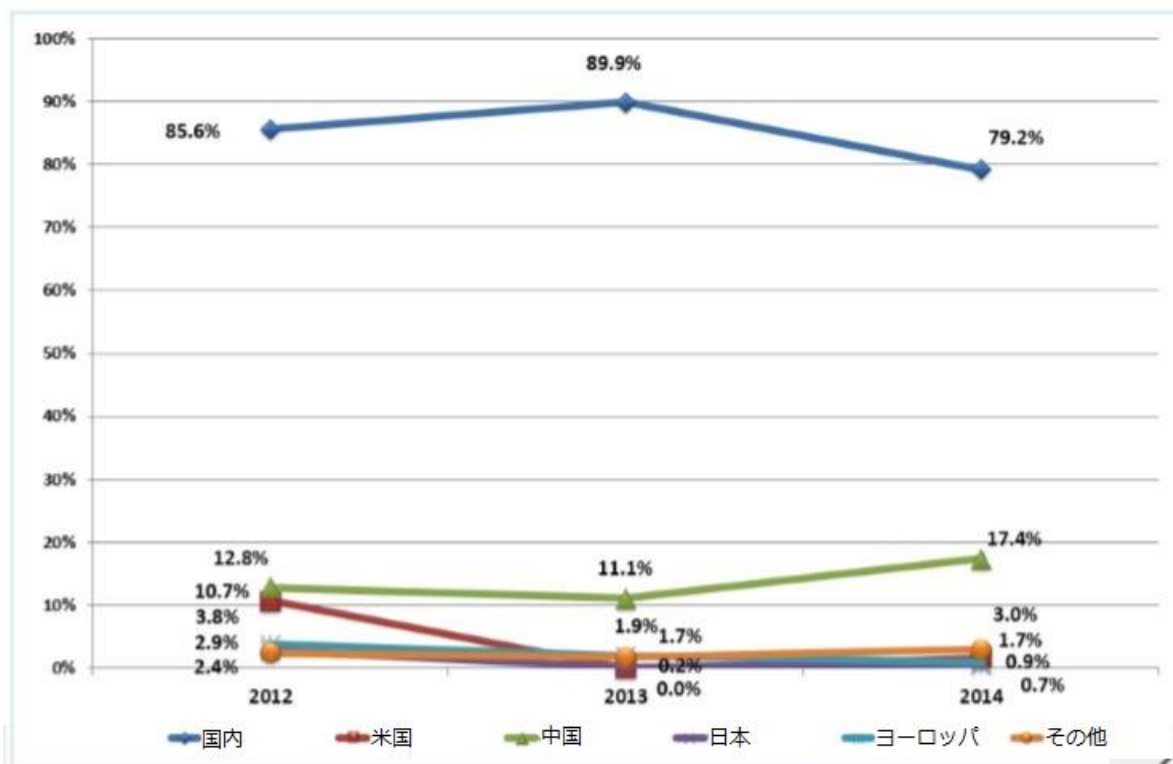
侵害製品製造地域の場合特徴的に国内 77.0%の他に中国が 21.0%を占めているが、特に大企業の場合中国での侵害被害比率が 53.1%と高い。また、侵害製品の流通地域を見ると、全体的に国内 79.2%の他にやはり中国が 17.4%と高く、また大企業の場合中国で 44.4%となっており、特に高いことが分かった。製造地域別の侵害被害比率を地域別に 3 ヶ年推移を見ると、国内被害比率の場合 2012 年に比べて 2013 年には増加したものの 2014 年に再び減少傾向にある。中国での侵害被害比率の場合反対の結果となっており、2012 年に比べて 2013 年に減少したものの 2014 年に再び増加する傾向にある([図 4.15])。



[図 4.15] 製造地域別の侵害被害比率

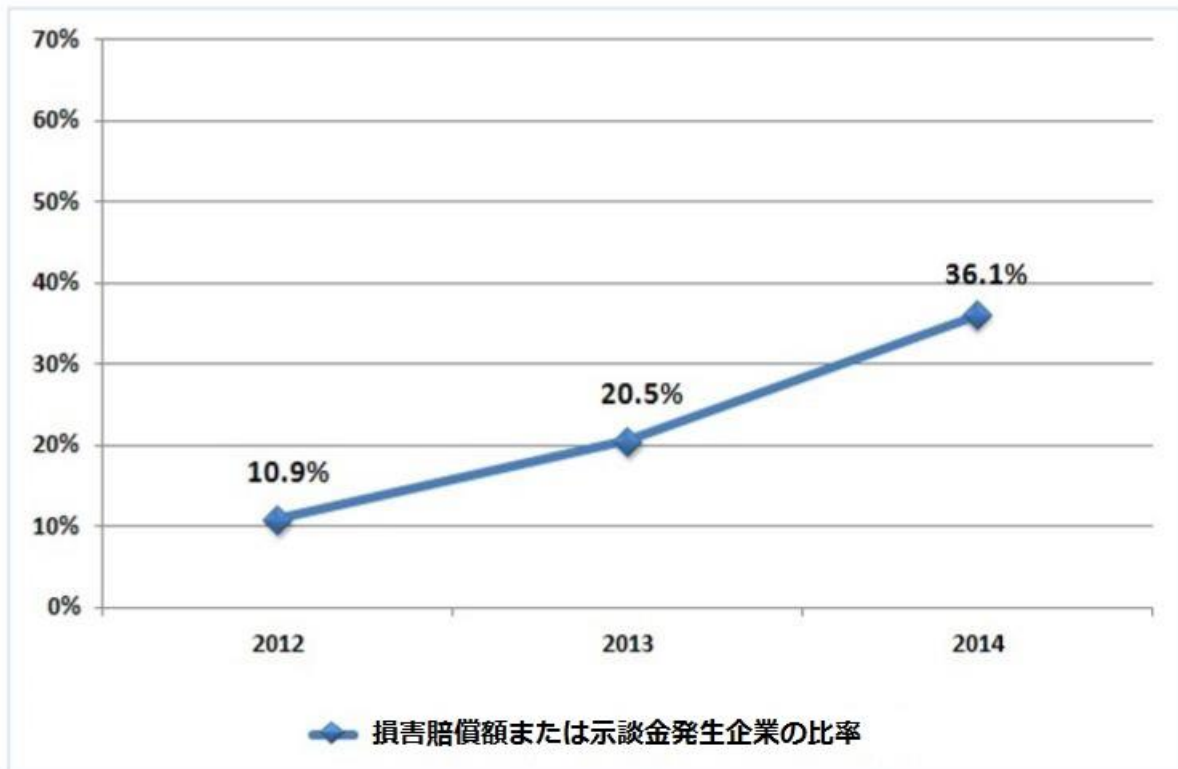
一方、侵害製品流通地域別の侵害被害比率を地域別に 3 カ年変化推移を見ると、製造地域別侵害被害比率の変化と類似する推移となっている。即ち、流通地域が国内である被害比率の場合 2012 年に比べて 2013 年に増加した後、2014 年再び減少に転じている。また、流通地域が中国である侵害被害比率の場合は逆に 2012 年に比べて 2013 年減少したが、2014 年再び増加に転じている([図 4.16])。

製造地域と流通地域を見ると、現在国内での製造及び流通の侵害被害が深刻であるが、中国での侵害被害は今後増加すると見られ、中国市場進出に先行して改善されるべき部分であると見られる。



[図 4.16] 流通地域別の侵害被害比率

知的財産権の侵害に対する事後対応として知的財産権の侵害を受けた企業の中で民事訴訟を通じて損害賠償額を認められたり、和解が成立した比率は 2014 年 36.1%で 2013 年に比べて 15.6%p 増加しているが、これは 2012 年以後持続的な増加傾向にある([図 4.17])。企業間で知的財産権の侵害が発生した場合積極的に手続き的な対応を進める事例が着実に増加していることが分かる。



[図 4.17] 損害賠償額または和解金が発生した企業の比率



# 用語整理

## 用語整理

### 登録補償

登録された職務発明を対象に支給する補償。

### 産業財産権

産業上の利用価値を持つ発明などに関する権利であり、本調査の対象は特許権、  
実用新案権、デザイン権、商標権である。

### 先行特許(技術)調査

新技術開発などのための研究開発(R&D)活動に先行して開発しようとする技術に対する先行技術または該当技術と同一もしくは類似する特許が存在するかどうかなどを調査。

### 実査

特許などの維持/放棄の決定、事業化有望技術及び移転対象技術などを発掘するために保有している知的財産権の価値を把握すること。

### 予備評価

提出された発明届出書に対して職務発明委員会などを通じて発明の評価、承継の可否、出願の可否、審査請求の可否などを決定すること。

### 自社実施補償

職務発明を発明者の属している会社が利用して収益が発生した場合に発明者に支給する補償。

### 知的財産

人間の創造的な活動産物として産業財産権(特許、実用新案、商標、デザイン、サービス表)、著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)、ノウハウなどを全て含む

### 知的財産権

産業、科学、文化、芸術分野の知的財産活動の結果として得られる法的権利であり、産業財産権の他に著作権、新知的財産権を総称

### 知的財産権の被侵害

知的財産権を侵害した製品・サービスが外部で製造・販売されることで該当知的財産権を保有する企業の利益に直間接的に被害を受けること

## 知的財産担当組織

知的財産 no

戦略企画、国内外産業財産権の出願及び登録・維持管理、知的財産権の動向調査、特許侵害関連の対応及び訴訟業務、知的財産権の販売またはライセンス交渉及び技術料管理などの業務を担当する組織。

## 知的財産保護活動

保有している知的財産を権利化したり、社内機密及びノウハウとして維持するなど創出された知的財産を私有化するための活動。

## 知的財産サービス

知的財産の創出、管理、活用、保護、取引などを支援する専門サービスとして情報調査・分析、技術移転・取引、IP 翻訳、コンサルティングなどの事業。

## 処分補償

職務発明を売却などを通じて処分して収入が発生した場合に支給する補償。

## 出願補償

出願が完了した職務発明を対象に支給する補償。

## 出願・審査費用

産業財産権の出願手数料、審査請求料、弁理士費用、決定系審判(特許出願に対する拒絶決定など審査官の処分不服して請求する審判)にかかった費用などを含めた金額。

## 他社実施補償

職務発明をライセンス契約などを通じて他企業に移転し、技術料収入が発生した場合に支給する補償。

## 特許維持費用

産業財産権の登録と権利維持にかかる金額で、登録料と維持年金を含めた金額。

# 付録

付録 1. 業種分類と韓国標準産業分類表  
(KSIC)との連結

付録 2. 調査票(企業)

付録 3. 調査票(大学・公共研究機関)

## <付録1>業種分類と韓国標準産業分類表(KSIC)との連結

知的財産活動実態調査の業種分類	韓国標準産業分類(KSIC)9次改訂	
農林水産及び鉱業、 飲食料及びタバコ製造業	A	農業、林業及び漁業
	B	鉱業
	C10	食料品製造業
	C11	飲料製造業
	C12	タバコ製造業
卸及び小売業  事業サービス業、通信業	G	卸及び小売業
	J	出版、映像、放送通信及び情報サービス業
	M	専門、科学及び技術サービス業
	N	事業施設管理及び事業支援サービス業
金融及び保険業	K	金融及び保険業
建設業	F	建設業
その他サービス業	D	電気、ガス、蒸気及び水道事業
	E	下水・廃棄物処理、原料再生及び環境復元業
	H	運輸業
	I	宿泊及び飲食店業
	L	不動産業及び賃貸業
	O	公共行政、国防及び社会保障行政
	P	教育サービス業
	Q	保健業及び社会福祉サービス業
	R	芸術、スポーツ及びレジャー関連サービス業
	S	協会及び団体、修理及びその他個人サービス業
繊維製品、衣服、靴製造	C13	繊維製品製造業；衣服を除く
	C14	衣服、衣服アクセサリ及び毛皮製品製造業

	C15	皮、靴及び靴製造業
紙及び印刷出版業	C17	パルプ、紙及び紙製品製造業
	C18	印刷及び記録媒体複製業
	C19	コークス、練炭及び石油精製品製造業
化学産業	C20	化学物質及び化学製品製造業；医薬品を除く
	C21	医療用物質及び医薬品製造業
鉄鋼及び金属産業	C22	ゴム製品及びプラスチック製品製造業
	C23	非金属鉱物製品製造業
	C24	1次金属製造業
電気電子産業	C26	電子部品、コンピュータ、映像、音響及び通信装備製造業
	C25	金属加工製品製造業；機械及び家具を除く
機械産業	C27	医療、精密、光学機器及び時計製造業
	C28	電気装備製造業
	C29	その他機械及び装備製造業
	C30	自動車及びトレーラー製造業
	C31	その他運輸装備製造業
その他製造業	C16	木材及び木製品製造業；家具を除く
	C32	家具製造業
	C33	その他製品製造業

## < 付録2 > 調査票：企業



実施機関：特許庁、  
貿易委員会  
承認番号：第 13802 号

# 知的財産活動調査票

- 企業用 -

2014

特許庁  
貿易委員会  
韓国知識財産研究院



# 知的財産活動調査票(企業用)

ID

--	--	--	--

## <調査概要>

本調査は韓国企業及び大学・公共(研)の知的財産活動状況を把握することで競争力強化に役立つ課題を発掘し、これを知的財産政策の樹立に反映することで企業及び大学・公共(研)の効果的な知的財産活動を支援するために特許庁、貿易委員会と韓国知識財産研究院が共同で行っております。

本調査は統計庁の承認統計として、この調査票に記載された内容は統計法第 33 条によって秘密が保護され、本調査の要約結果は今後ご回答頂いた企業及び公共研究機関のご担当の方に e-mail で送付致します。本調査にご協力いただき、ありがとうございます。

## <お問合せ>

韓国知識財産研究院 (KIIP)

(株)コリアデータネットワーク (KDN) 電話番号 : 02-2183-9159

## <送付方法>

調査票の送付手段はメール、FAX、郵便いずれも可能で、書類様式は韓国知識財産研究院のホームページ(<http://www.kiip.re.kr>)からダウンロードすることができます。

## <送り先>

135-914 ソウル市江南区駅三洞 667-14KDN ビル チェ・キュヒョック 研究員

FAX : 02-548-5144、02-512-0777 E-mail : [kdn21@kdn21.co.kr](mailto:kdn21@kdn21.co.kr)

企業名		業種分類* (下記の産業分類表を参照して一つだけ選択)		主要事業 製品名**
企業(本社) 所在地		法人番号		
回答者名前		部署/職位		
回答者連絡先		回答者 E-mail		

\*\* (例示 1) 「業種分類」 32. 電気装備製造業 「主要事業製品名」 : 変圧器

\*\* (例示 2) 「業種分類」 : 34. 自動車及びトレーラー製造業 「主要事業製品名」 : 自動車用エンジン

\*9 次標準産業分類(新分類)

<p>1. 農業、林業及び漁業</p> <p>2. 鉱業</p> <p>3. 電気、ガス、蒸気及び水道事業</p> <p>4. 下水・廃棄物処理、原料再生及び環境復元業</p> <p>5. 建設業</p> <p>6. 卸及び小売業</p> <p>7. 運輸業</p> <p>8. 宿泊及び飲食店業</p> <p>9. 出版、映像、放送通信及び情報サービス業</p> <p>10. 金融及び保険業</p> <p>11. 不動産及び賃貸業</p> <p>12. 専門科学及び技術サービス業</p> <p>13. 事業施設管理及び事業支援サービス業</p>	<p>23. コークス、練炭及び石油精製品製造業</p> <p>24. 化学物質及び化学製品製造業</p> <p>25. 医療用物質及び医薬品製造業</p> <p>26. ゴム及びプラスチック製品製造業</p> <p>27. 非金属鉱物製品製造業</p> <p>28. 第1次金属産業</p> <p>29. 金属加工製品製造業</p> <p>30. 電子部品、コンピュータ、映像、音響及び通信装備製造業</p> <p>31. 医療、精密、光学機器及び時計製造業</p> <p>32. 電気装備製造業</p> <p>33. その他機械及び装備製造業</p> <p>34. 自動車及びトレーラー製造業</p> <p>35. その他運輸装備製造業</p> <p>36. 家具製造業</p> <p>37. その他製品製造業</p>
<p>14. 食料品製造業</p> <p>15. 飲料製造業</p> <p>16. タバコ製造業</p> <p>17. 繊維製品製造業</p> <p>18. 衣服、衣服アクセサリー及び毛皮製品製造業</p> <p>19. 皮、鞆及び靴製造業</p> <p>20. 木材及び木製品製造業</p> <p>21. パルプ及び紙製品製造業</p> <p>22. 印刷及び記録媒体複製業</p>	<p>38. 公共行政、国防及び社会保障</p> <p>39. 教育サービス業</p> <p>40. 保健業及び社会福祉サービス業</p> <p>41. 芸術、スポーツ及びレジャー関連サービス業</p> <p>42. 協会及び団体、修理及びその他個人サービス業</p> <p>43. 世帯内の雇用活動及び他に分類されない自家消費生産活動</p> <p>44. 国際及び外国機関</p>

## I. 会社の一般事項及び知的財産インフラ

### ● 会社の形態及び規模

1. 企業類型による会社の形態(該当欄に✓チェック、2013年12月基準)

企業類型 1	企業類型 2	企業類型 3
・独立企業 ① ・国内グループ系列会社 ② ・海外グループ系列会社 ③	・大企業 ① ・中堅企業* ② ・一般中小企業** ③ ・ベンチャー企業/ INNO-BIZ 企業 ④	・企業研究所(または R&D ① 専担部署)を保有 ・企業研究所を ② 保有していない

\*中堅企業とは「産業発展法」第10条の2第1項の要件を全て備えた企業である。

\*\*中小企業とは「中小企業基本法」第2条第1項及び同法施行令第3条(中小企業の範囲)による企業である。

2. 従業員数、売上高、輸出額、R&D 人材及び費用(該当欄に数字で記入、2013年または会計年度基準)

従業員数 (臨時・日雇職を 除く)	名		総売上 高	億ウォン	
研究開発(R&D) 人材*	全体 名		輸出入 活動の 有無及 び総輸 出入額	輸出活動の有無及び総輸出額	
	男性 名	女性 名		①有る(総輸出額: 億ウォン)	②無い
研究開発(R&D)費* ※	億ウォン		輸出入 活動の 有無及 び総輸 出入額	輸入活動の有無及び総輸入額	
				①有る(総輸出額: 億ウォン)	②無い

\***研究開発人材**は研究所及び研究専担部署などに所属され、科学技術、産業技術などの研究開発活動に従事している人材と生産技術人材を意味し、機能職従事者、臨時職や管理職従事者は除く。「研究開発活動調査」に回答した場合は「科学技術研究開発活動調査票」の「研究開発人材」項目のうち「研究員数」を参照して研究開発人材数

を記入。

※※**研究開発費**は新しい技術、製品を開発したり、既存の知識を活用して新しい方法を探し出すために行われた調査・研究活動に支出された費用であり、間接費は除く。

「科学技術研究開発活動調査」に回答した場合は「科学技術研究開発活動調査票」の「研究開発費」項目を参照して記入。

### 知的財産※担当人材

※**知的財産**とは人間の創造的な活動の産物を総称する用語として、産業財産権(特許、実用新案など)、著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)及び権利化されていないアイデア、ノウハウなどを全て含む。

※**産業財産権**とは産業上の利用価値を持つ発明などに関する権利として、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権を含む。

※※**著作権**とは著作者が自分の著作物を独占的に利用したり、それを他人に許諾できる人格的、財産的権利を意味する。

※※※**新知的財産権**とは経済・社会または文化の変化や科学技術の発展によって新しい分野で出現する知的財産(知識財産基本法第3条の2)で、伝統的な知的財産権の範疇では保護が難しいコンピュータプログラム、遺伝子組み換え動植物、半導体設計、インターネット、キャラクター産業などに関連する権利を意味する。

※**特許権**とは産業財産権の中で最も高度な技術性を持つもので、基本的に産業上の利用可能性、新規性、進歩性の3つの要件によって登録が可能。

※※**実用新案権**とは既存の物品を改良して実用性と有用性を高めた考案を出願して付与を受ける権利を意味する。

※※※**デザイン権**とは産業的物品または製品の独創的かつ装飾的な外見形状を保護するために登録を通じて許容された権利を意味し、技術とは関係なく物品の美的外見を視覚的な観点から把握できるものを意味する。

※※※※**商標権**とは生産者または商人が商標を特許庁に出願して登録することで登録商標を指定商品に独占的に使用できる権利を意味する。

3. 知的財産担当組織※の存在状況(該当欄に✓チェック)

担当組織保有			担当組織なし
独立専担部署	法務組織/研究開発組織内	その他組織内	
①	②	③	④

4. 知的財産担当組織総括者の職位(1つだけV表示)

①社員 ②代理 ③課長 ④次長 ⑤部長 ⑥役員 ⑦その他( )

5. 知的財産担当人材\*の数(該当欄に数字で記入、いなければ0と表示)

知的財産専任人材**	名	男性	名
		女性	名
その他部署業務(例:総務、人事、R&D企画)との 兼任人材	名	男性	名
		女性	名

\*知的財産担当組織または人材は知的財産の戦略企画、国内外産業財産権の出願及び登録・維持管理、知的財産権の動向調査、特許侵害関連の対応及び訴訟業務、知的財産権の販売またはライセンス交涉及び技術料管理などの業務を担当する組織及び人材を意味する。


\*\*知的財産専任人材:知的財産関連業務だけを専門的に担当する人材

6. 知的財産担当者(兼任人材を含む)の主要業務(知的財産担当人材を1名以上保有する場合該当欄に✓チェック)

業務内容	人材数				
	ない	1~3名 未満	3~5名 未満	5~10名 未満	10名以上
産業財産権の出願/登録/維持	①	②	③	④	⑤
知的財産関連の紛争/訴訟	①	②	③	④	⑤
ライセンスなど知的財産の活用	①	②	③	④	⑤
知的財産の評価/分析/審査	①	②	③	④	⑤
知的財産戦略の樹立	①	②	③	④	⑤
知的財産関連の教育	①	②	③	④	⑤

7. 知的財産専任人材に対する今後の採用計画（該当欄に✓チェック）

現在保有していない場合		現在保有している場合	
新規採用計画がある	採用計画はない	追加採用計画がある	追加採用計画はない
①	②	③	④

 知的財産担当人材の職務教育

8. 知的財産担当人材に対する職務教育の状況（該当欄に✓チェック）

職務教育を行っている		しない
機関が独自に実施	外部機関を通じて	
①	②	③

9. 知的財産担当人材向け職務教育の必要性（該当欄に✓チェック）

必要ない	←	普通	→	とても必要
①	②	③	④	⑤

10. 知的財産人材向け職務教育の実施を希望する場合、主に取り扱うべき教育内容（該当するものは全て✓チェック）

- ①特許制度      ②特許明細書の作成法      ③特許情報検索      ④特許紛争（訴訟）  
 ⑤特許情報の分析法（特許マップ）      ⑥特許ライセンス（技術事業化）  
 ⑦海外特許出願及び訴訟      ⑧営業秘密保護      ⑨その他（      ）

11. 知的財産人材の能力を高めるため政府が最も推進を急ぐべき課題（1つだけ✓チェック）

- ①大学に特許関連教育課程及び学科の開設  
 ②企業を対象とする実務中心教育課程の構成及び教材の開発  
 ③企業の特許教育を担当する専門講師の育成      ④新規知的財産人材の養成  
 ⑤既存人材のための再教育プログラムの提供  
 ⑥知的財産関連のコンサルティングまたは相談の提供      ⑦その他（      ）

12. 知的財産担当者に対する人件費及び教育費、知的財産関連の教育費

（該当欄に数字で記入、□2013年または□会計年度基準）

知的財産担当者に対する人件費※	(百万ウォン)
教育費(知的財産担当者対象)※※	(百万ウォン)
知的財産関連の教育費(研究開発者及び従業員対象)※※※	(百万ウォン)

※他業務と兼職である場合、知的財産関連業務の比重を考慮してお答えください。

※※知的財産担当者及び担当部署の知的財産専門能力を高めるために行われた対内外教育プログラムへの参加及び知的財産関連専門セミナーの進行など教育と関連する費用を意味する。

※※※知的財産の創出、権利化、活用などに関連して企業内部の研究開発者及び従業員の基礎的な知的財産関連素養を涵養するための教育費用を意味する。

### ● 知的財産サービスの活用状況

※知的財産(IP)サービスとは知的財産の創出、保護、活用などを支援する専門サービスとして、情報調査・分析、技術移転・取引、翻訳、コンサルティングなどの事業

13. 国内知的財産サービスの活用状況及び分野別支出額(該当欄に✓チェック及び金額を記入)

現在の利用状況 (2013 基準、該当欄 に✓チェック)	分野	説明	支出額(2013年) (ない場合 0 記入)	
利用している	①	IP 情報調査/ 分析	特許 DB、調査分析、特許マップの作成、動向分析など	万ウォン
		技術移転/取引	技術マーケティング、特許等級評価、技術評価など	万ウォン
		IP 翻訳	明細書の翻訳、仕様書の翻訳、翻訳出版など	万ウォン
		IP コンサルティング	IP 経営、IP 戦略コンサルティングなど	万ウォン


	IP インフラ	IP 教育、IP システムの構築など	万ウォン
	その他	IP 法律代理業務	万ウォン
利用していない	利用していない理由(複数回答可能)		
	②	自社の保有人材で充分該当業務を行うことができる	
	③	必要性は認識しているもののどの機関を利用すればいいかわからない	
	④	知的財産サービスにかかる費用が高価である	
	⑤	知的財産サービス提供機関の品質が信頼できない	
	⑥	知的財産サービス提供機関の情報保安が信頼できない	
	⑦	その他( )	

14. (Q13 で①と答えた場合)知的財産サービス提供機関別の利用比重(該当欄に数値を記入)

区分	利用比重
民間知的財産サービス専門企業(弁理士事務所を除く)	%
弁理士事務所	%
韓国特許情報院、韓国発明振興会、技術保証基金など公共機関	%
合計	100%

## II. 特許基盤の知的財産活動

※該当部分の調査項目は「特許に特異的な項目」に対してより明確な現状を把握するためのもので、保有している産業財産権(特許権、実用新案権、商標権、デザイン権)のうち特に特許を念頭に置いてお答えください。

 先行特許調査\*など特許情報の活用

\*先行特許(技術)調査とは新技術開発などのための研究開発(R&D)活動に先行して開発しようとする技術に対する先行技術または該当技術と同一もしくは類似する特許が存在するかどうかなどを調査することである。機関レベルで行う先行技術調査活動及び



研究者レベルで行う先行技術調査活動を全て含む。

15. 特許(技術)情報調査の現状(該当欄に✓チェック及び数字の記入)

実施状況	
行っている(✓チェック及び数字記入後、Q17へ)	① 研究開発企画段階で全体研究開発課題のうち( )%
行っていない(✓チェック後、Q16へ)	②

16. (先行特許調査を行っていない場合)その主な理由(該当欄に✓チェックまたはその他意見の作成後、Q18へ)

- ①先行特許(技術)調査の実施による費用の負担
- ②先行特許(技術)調査の実施のための専門人材の不足
- ③先行特許(技術)調査の実施に対する認識不足
- ④先行特許(技術)調査活動の実効性不足(技術の寿命周期の短縮などで先行技術調査の実効性減少など)
- ⑤その他(\_\_\_\_\_)

17. (先行特許調査を行っている場合)実施人材(該当するものは全て✓チェック後、Q18へ)

内部人材			外部人材	
知的財産 専担人材	R&D 人材	その他(企画など)人材	弁理士/ 弁理士事務所	専門調査/ 評価機関
①	②	③	④	⑤

18. 特許(技術)情報調査の必要性(該当欄に✓チェック)

必要性				
必要ない	←	中間	→	とても必要
①	②	③	④	⑤

## ● 職務発明補償

※**職務発明**：従業員（法人の役員を含む）がその職務に関して発明したものが性質上使用者・法人の業務範囲に属し、その発明をした行為が従業員の現在または過去の職務に属する発明（特許、実用新案、デザイン）

※**職務発明補償制度**：従業員は職務発明に対して特許などを受けられる権利や特許権などを契約や勤務規定によって使用者・法人に承継させたり、専用実施権を設定した場合は正当な補償を受けられる権利を持つ制度（発明振興法）

### 19. 職務発明補償制度に対する認識度（該当欄に✓チェック）

区分	全く知らない ← → 非常に詳しい				
	①	②	③	④	⑤
(1) 職務発明補償制度に対して	①	②	③	④	⑤
(2) 職務発明と個人発明（職務発明以外の発明）の概念に対して	①	②	③	④	⑤
(3) 職務発明に対する権利の帰属または承継に対して	①	②	③	④	⑤
(4) 補償の算定方法（金銭的・非金銭的）に対して	①	②	③	④	⑤

### 20. 職務発明補償規定\*の保有・活用状況（該当欄に✓チェック）

保有している（該当欄に✓チェック後、Q22へ）		保有していない （チェック後、Q21へ）
企業独自に 職務発明補償規定を作成・活用	特許庁など関連機関が作成・普及した標準化された職務発明補償規定を保有・活用	
①	②	③

\*職務発明補償規定：使用者・法人が承継した従業員の職務発明に対して正当な補償を定めた契約や勤務規定

### 21. （職務発明補償規定を保有していない場合）その主な理由（該当欄に✓チェックまたはその他意見の作成後、Q24へ）

- ①職務発明補償金を支給する必要がない                      ②他職員との衡平性
- ③補償規定がなくても別途のインセンティブが与えられる
- ④補償金を支給する場合、企業の負担が大きくなるため
- ⑤必要性は認識しているもののどのように導入すればいいかわからない
- ⑥使用者の導入意志が全くない                      ⑦その他(\_\_\_\_\_)

22. 職務発明補償の実施状況と補償金の水準(該当欄に✓チェック後、Q23へ)

\*出願補償：出願が完了した職務発明を対象に支給する補償

\*\*登録補償：登録された職務発明を対象に支給する補償

\*\*\*自社実施補償：職務発明を発明者が属している会社で利用して収益が発生した場合に支給する補償

\*\*\*\*他社実施補償：職務発明をライセンス契約などを通じて他企業に移転し、技術料収入が発生した場合に支給する補償

\*\*\*\*\*処分補償：職務発明を売却などを通じて処分して収入が発生した場合に支給する補償

区分	実施状況				金銭的補償を実施する場合、職務発明補償金の水準
	金銭的補償	非金銭的補償(昇進、成果評価反映)	両方補償	実施しない	
発明提案(発明届出)補償	①	②	③	④	万ウォン
出願留保補償	①	②	③	④	万ウォン
国内特許出願補償*	①	②	③	④	万ウォン
国内特許登録補償**	①	②	③	④	万ウォン
海外特許出願補償	①	②	③	④	万ウォン
海外特許登録補償	①	②	③	④	万ウォン
その他産業財産権の国内登録補償	①	②	③	④	万ウォン
その他産業財産権の海外	①	②	③	④	万ウォン

登録補償						
					一定比率支給の場合	固定金額支給の場合
自社実施補償***	①	②	③	④	収入金の平均____%	万ウォン
他社実施補償****	①	②	③	④	収入金の平均____%	万ウォン
処分補償*****	①	②	③	④	収入金の平均____%	万ウォン

23. 支給された職務発明関連の補償費用\* (□2013年または□会計年度基準、該当欄に数字で記入)

補償の種類	補償費用
(1) 発明届出補償/出願/登録補償	(百万ウォン)
(2) 実施/処分補償	(百万ウォン)


\*職務発明補償費用は貴社が定めた補償制度に基づき発明者と創作者などに支払った補償金である(実施補償、処分補償など)

24. 職務発明補償と関連するあらゆる制度の効果(該当欄に✓チェック)

(企業レベルや国家レベルで現在の実施状況とは関係なくお答えください。)

関連制度		効果ない ← →とても効果的				
		①	②	③	④	⑤
従業員の職務発明に対する補償実施または補償水準の拡大(企業→発明者)	発明の品質及び件数の増加	①	②	③	④	⑤
	技術流出の防止	①	②	③	④	⑤
職務発明補償制度の実施企業に対する税金の減免(政府→企業)	発明の品質及び件数の増加	①	②	③	④	⑤
	技術流出の防止	①	②	③	④	⑤
職務発明補償金に対する所得税の非課税	発明の品質及び件数の増加	①	②	③	④	⑤
	技術流出の防止	①	②	③	④	⑤

(政府→発明者)						
----------	--	--	--	--	--	--

 技術取引機関、技術マーケティング会社との協力

25. 最近3年間(2011～2013年)技術取引、技術マーケティングのために大学・公共研究機関 TLO や民間技術取引機関などに業務を依頼したり、業務協約を締結しているかどうかに関して(該当欄に✓チェック)

	業務協約を締結	業務を依頼	依頼しない
(1) 大学・公共研究機関 TLO、産学協力団	①	②	③
(2) 地域技術移転センター、技術取引所など 国内公共機関	①	②	③
(3) 国内民間技術仲介、技術マーケティング会社	①	②	③
(4) 海外機関または民間会社	①	②	③


26. (技術取引機関などに業務を依頼した場合)主な費用支給方法(該当欄に✓チェック)

- ① 調査/マーケティング費用など活動費(前金)+成功報酬(定額)
- ② 調査/マーケティング費用など活動費(前金)+成功報酬(技術移転収益などによる定率)
- ③ 成功報酬(定額)    ④ 成功報酬(技術移転収益などによる定率)    ⑤ その他

27. 技術取引システムの活用度(該当欄に✓チェック)

	活用しない	活用度				
		低い	← 中間 →	高い		
(1) IP-mart(インターネット特許技術広場)、NTB など国内オンライン取引システム/DB	①	②	③	④	⑤	
(2) 特許技術移転説明会など国内オフライン取引システム	①	②	③	④	⑤	



 外部からの知的財産導入(outsourcing)\*の方向と戦略

※外部から導入した知的財産は産業財産権(特許、実用新案、商標、デザイン)、著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)、ノウハウなどを全て含む。

32. 外部からの知的財産導入方法による実績(該当欄に数字で記入)

※導入した回数ではなく、導入した産業財産権やノウハウの総件数でご記入ください。

□2013年または□会計年度基準		国内から	海外から
外部から導入した知的財産件数*		件 (このうち特許件数)	件 (このうち特許件数)
→ 実施許諾(licensing-in)を通じて導入		件	件
→ 購買/譲受を通じて導入		件	件
クロスライセンス、特許プール(patent pool)を通じて相互実施または共有形態で導入		件	件

33. 外部からの知的財産導入経路による実績(該当欄に✓チェック)

(1)~(7)の機関から最近3年間(2011~2013年)の知的財産導入経験		ない	件数				
			1件	2~3件	4~5件	6~9件	10件以上
国内	(1)グループ系列会社	○	①	②	③	④	⑤
	(2)需要(納品)/供給(下請)企業	○	①	②	③	④	⑤
	(3)その他企業	○	①	②	③	④	⑤
	(4)大学	○	①	②	③	④	⑤
	(5)出捐(研)など公共研究機関	○	①	②	③	④	⑤
海外	(6)企業	○	①	②	③	④	⑤
	(7)大学及び研究所	○	①	②	③	④	⑤

34. 外部から知的財産を導入するための投資に対する今後の計画(該当欄に✓チェック)

①現在の水準より縮小

②現在の水準を維持

③現在の水準より拡大

35. (Q34 で③を選択した場合)知的財産導入に向けた投資の拡大方向(該当するものは全て✓チェック)

国内		海外	
企業	大学及び研究機関	企業	大学及び研究機関
①	②	③	④

### 知的財産活用の方向と戦略

36. 保有している知的財産権\*に対する実査\*\* (評価)の実施状況(該当欄に✓チェック及び数字記入)

実施状況	
実施している	① 保有している全体知的財産権のうち____%
実施していない(✓チェック後、Q37へ)	②

※**知的財産権**とは産業財産権(特許、実用新案など)の他に著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)を総称

※**保有知的財産権に対する実査**とは特許などの維持/放棄の決定、事業化有望技術及び移転対象技術などを発掘するために保有している知的財産権の価値を把握することを意味する。

37. (実査を実施していない場合)その主な理由(該当欄に✓チェックまたはその他意見の作成後、Q39へ)

①知的財産権実査の実施による費用の負担

②知的財産権実査を実施するための専門人材の不足

③知的財産権実査の実施に対する認識不足

④知的財産権実査を行うには累積された知的財産権数が少ないため行っていない

⑤実査(評価)活動の実効性不足(実査結果の活用度が低い)

⑥その他(\_\_\_\_\_)




38. (実査を実施している場合)実施人材(該当する全てのものに✓チェック後、Q39へ)

内部人材			外部人材	
知的財産 専担人材	R&D 人材	その他(知的財産実査 委員会など)人材	弁理士/弁理士 事務所	専門調査 /評価機関
①	②	③	④	⑤

39. 実際実施の必要性(該当欄に✓チェック)

必要性				
必要ない	←	中間	→	とても必要
①	②	③	④	⑤

 知的財産\*の売却または移転状況

※知的財産は産業財産権(特許、実用新案、商標、デザイン、サービス表)、著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)、ノウハウなどを全て含む

40. 知的財産の売却または移転実績(該当欄に数字で記入、2013年基準)

<input type="checkbox"/> 2013年または <input type="checkbox"/> 会計年度基準	国内に売却または移転	海外に売却または移転
他企業などに売却または移転した知的財産の件数*	件 (このうち特許件数 件)	件 (このうち特許件数 件)
実施許諾を通じて移転 (licensing-out)	件 (このうち特許件数 件)	件 (このうち特許件数 件)
→ 売却/譲渡を通じて売却 (sale)	件 (このうち特許件数 件)	件 (このうち特許件数 件)
クロスライセンス、特許プール(patent pool)を通じて相互実施または共有形態で移転	件 (このうち特許件数 件)	件 (このうち特許件数 件)

41. 知的財産の売却または移転の際、最も大きな問題(該当欄に✓チェック)



※産業財産権は各種 R&D 事業及び主要認証を獲得する上で基盤となる根拠になり得るため、本質問では貴社が国家及び民間 R&D 事業を受注する際(提案書の作成など)、各種認証獲得のための申請の際に出願及び登録産業財産権を活用した事例を全て含む。

※NET(New Excellent Technology) 認証とは技術標準院及び韓国産業技術振興協会が運営主体であり、新技術を早期に発掘して優秀性を認証することで、新技術の商用化及び取引を促進するとともに初期市場進出基盤作りを目的として設立された認証制度

※※NEP(New Excellent Product) 認証とは技術標準院が運営主体であり、国内で初めて開発された技術またはこれに準ずる代替技術を適用した製品を認証することで製品の初期販路の開拓を支援し、技術開発を促進することを目的に設立された制度


※※※世界一流商品認証とは産業資源通商部が運営主体であり、大韓民国国籍企業が生産する製品として一定の条件を満たせる商品のうち、産業資源通商部長官が「現在世界一流商品」または「次世代世界一流商品」として選定した商品を意味する。

(1) 産業財産権 を活用した R&D 受注の状況	R&D 受注のために産業財産権を活用した経験がある		活用経験無し	
	政府 R&D に活用	民間 R&D に活用		
	①	②	③	
(2) 産業財産権 を活用した主 要認証獲得の 状況	主要認証獲得のために産業財産権を活用した経験がある			活用経験無し
	NET 認証 獲得	NEP 認証 獲得	世界一流商 品認証獲得	
	①	②	③	④ ( )

44. 産業財産権を活用しなかった主な理由(該当欄に✓チェックまたはその他意見の作成)

- ①(自社実施)産業財産権の活用に必要な資本など生産要素の不足
- ②(自社実施、他社実施)活用するためには該当産業財産権の他に後続研究開発を通じた関連産業財産権の獲得が必要であるが、該当後続活動が不十分
- ③(他社実施、技術移転)産業財産権に対する需要機関の発掘が難しい
- ④(他社実施、技術移転)産業財産権に対する需要機関との交渉が難しい
- ⑤既存産業財産権との利用・抵触関係によって紛争の恐れがあるため、活用不可

⑥その他( \_\_\_\_\_ )

 政府の政策支援及びその必要性

45. 国内企業の効果的な知的財産創出に向けた政策支援の必要性

	政府政策の必要性				
	低い	←	中間	→	高い
(1)職務発明補償制度の実施企業に対する税制メリットの付与、関連規定の整備などを通じて企業が職務発明補償制度を導入したり、補償水準が拡大できるように支援	①	②	③	④	⑤
(2)特許情報活用拡散事業の拡大などを通じて深みのある先行特許調査と特許情報活用を支援	①	②	③	④	⑤
(3)中小企業特許コンサルティング事業の拡大などを通じて中小企業の知的財産権創出活動を支援	①	②	③	④	⑤
(4)多様な技術分野に対する特許マップ(patent map)の構築支援	①	②	③	④	⑤
(5)研究者などを対象とする知的財産権関連教育の支援(例：教育プログラムの開発及び普及、教育関連費用の支援など)	①	②	③	④	⑤
(6)その他( _____ )	①	②	③	④	⑤

46. 国内企業の効果的な知的財産活用のための政策支援

	政府政策の必要性				
	低い	←	中間	→	高い
(1)新技術製品の販路支援及びマーケティング活動支援	①	②	③	④	⑤
(2)偽造品及び模倣品の取締り強化	①	②	③	④	⑤
(3)新技術事業化のための中小/ベンチャー創業支援	①	②	③	④	⑤
(4)特許技術取引、流通システムの改善	①	②	③	④	⑤
(5)優秀技術の輸出支援	①	②	③	④	⑤

(6) 地域知的財産センターなどを通じた出願から事業化までの特許総合コンサルティング支援 (one-stop service)	①	②	③	④	⑤
(7) その他 ( )	①	②	③	④	⑤

#### IV. 知的財産保護活動

##### ● 知的財産保護の方向と戦略

47. 産業財産権の出願などに先行して社内予備評価<sup>※</sup>を実施しているか。(該当欄に✓チェック及び数字で記入)

実施状況	
実施している (✓チェック及び数字記入後、Q49へ)	① 全体届出發明のうち _____ %
実施していない(✓チェック後、Q48へ)	②

※「予備評価」とは提出された発明届出書に対して職務発明委員会などを通じて発明の評価、承継の可否、出願の可否、審査請求の可否などを決定することを意味する。

48. (予備評価を実施していない場合)その主な理由(該当欄に✓チェックまたはその他意見の作成後、Q50へ)

- ① 予備評価の実施による費用の負担
- ② 予備評価を実施するための専門人材の不足
- ③ 予備評価の実施に対する認識不足
- ④ 予備評価活動の実効性不足(予備評価のスクリーニング機能などが満足に働かない)
- ⑤ その他(\_\_\_\_\_)

49. (予備評価を実施している場合)遂行人材(該当するもの全てに✓チェック後、Q50へ)

内部人材			外部人材	
知的財産専門	R&D 人材	その他(知的財産実)	弁理士/	専門調査/

担当人材		査委員会など)人材	弁理士事務所	評価機関
①	②	③	④	⑤

50. 予備評価実施の必要性(該当欄に✓チェック)


必要性				
必要ない	←	中間	→	とても必要
①	②	③	④	⑤

51. (模倣者などから)研究開発活動の成果を保護するために活用する戦略(該当欄に✓チェック)

	活用 しない	活用度				
		低い	← 中間	→	高い	
(1)特許など産業財産権の出願/登録	①	②	③	④	⑤	
(2)営業秘密及びノウハウとして維持	①	②	③	④	⑤	
(3)競合社より先に市場を先占	①	②	③	④	⑤	
(4)複雑な設計方法を採用	①	②	③	④	⑤	

52. 発明届出(Invention disclosure)件数対比特許など産業財産権の出願比率

<input type="checkbox"/> 2013年または <input type="checkbox"/> 会計年度基準	比率
発明届出(Invention disclosure)件数=100とする場合、	100((1)+(2)+(3)+(4))%
(1)産業財産権の出願など公式的な権利保護手続きを進行	%
(2)(営業秘密として維持など)非公式的な権利保護手続きを進行	%
(3)(経済性、技術性不足などの理由で)出願を留保または放棄する	%
(4)その他:	%

 知的財産の管理及び保護に関する認識度

53. 現在国内の知的財産保護水準\*に対する意見(該当欄に✓チェック)

大幅な 弱化が必要	漸進的な 弱化が必要	現在の水準が 適正	漸進的な 強化が必要	大幅な 強化が必要
①	②	③	④	⑤

※知的財産保護水準は特許制度のように知的財産に権利を付与するシステムの効率性と知的財産権が他人によって侵害を受けた時に対抗できる行政的、司法的措置が如何に整えられているのかを意味する。

54. 産業財産権の海外出願/登録の実績(該当欄に数字で記入)

		特許権の 海外出願/登録	デザイン権の 海外出願/登録	商標権の 海外出願/登録	
2013年 実績	(個別国家)出願件数※	(件)	(件)	(件)	
	→	米国など北米地域	(件)	(件)	(件)
		日本などアジア地域	(件)	(件)	(件)
		ヨーロッパ(EU)	(件)	(件)	(件)
		その他の地域	(件)	(件)	(件)
	PCT出願**		(件)		
2013年 実績	登録件数※		(件)	(件)	(件)
	→	米国など北米地域	(件)	(件)	(件)
		日本などアジア地域	(件)	(件)	(件)
		ヨーロッパ(EU)	(件)	(件)	(件)
		その他の地域	(件)	(件)	(件)

※同じ産業財産権を複数の国家に個別に出願または登録した場合にはこれを全て合算してご記入ください。例えば、A という特許を米国、日本、ドイツに出願した場合、出願件数は1ではなく3でご記入ください。

\*\*但し、PCT出願の場合は出願書に記載されている指定国の数に関係なく、1件としてご記入ください。

 産業財産権出願の今後の計画

55. 2014年産業財産権の予想国内出願件数(該当欄に数字で記入及び✓チェック)

		国内特許	国内実用新案	国内デザイン	国内商標
2014年	出願/予想出願件数	(件)	(件)	(件)	(件)
2015年 以後	縮小	①	①	①	①
	維持	②	②	②	②
	拡大	③	③	③	③

56. 貴社の産業財産権国内出願の増減に影響を及ぼす要因(該当欄に✓チェック)

主要産業財産権の国内出願の増減に影響を及ぼす要因		重要度				
		低い ← 中間 → 高い				
企業内部的 な要因	①研究開発投資の増減による研究成果の変化	①	②	③	④	⑤
	②企業の事業戦略の変化(事業分野の多角化または事業構造調整など)	①	②	③	④	⑤
	③企業の産業財産権戦略の変化(量または品質中心の産業財産出願戦略、維持費用対比収益性戦略の変化など)	①	②	③	④	⑤
外部環境的 な要因	④市場及び技術競争環境の変化(市場の拡大または縮小、新技術または新市場の出現など)	①	②	③	④	⑤
	⑤国内及び世界景気の変動(国内総生産の増減、物価及び為替の変化、世界金融危機など)	①	②	③	④	⑤
	⑥産業財産権出願環境の改善及び支援制度の強化(出願手数料の減免、手続きの簡素化、産業財産権創出支援制度など)	①	②	③	④	⑤

57. 出願・審査・維持費用(□2013年または□会計年度基準、弁理士費用を含む)

		国内出願	海外出願 (PCT出願を含む)
出願・審査費用*		(百万ウォン)	(百万ウォン)
→	特許/実用新案権の出願・審査費用	%	%



	維持費用**	(百万ウォン)	(百万ウォン)
→	特許/実用新案権の維持費用	%	%

\*出願・審査費用は産業財産権の出願手数料、審査請求料、弁理士費用、決定系審判（特許出願に対する拒絶決定など審査官の処分に不服して請求する審判）にかかった費用などを含めた金額である。

\*\*維持費用は産業財産権の登録と権利維持にかかる金額であり、登録料と維持年金を含めた金額である。

### 営業秘密管理及び技術流出防止管理の状況

58. 営業秘密管理及び技術流出防止指針の保有及び遵守状況

- ① 営業秘密管理指針及び技術流出防止指針があり、これを遵守している。
- ② 営業秘密管理指針及び技術流出防止指針はあるが、これに対する認識度が低い。
- ③ 関連指針がない。

59. 営業秘密管理及び技術流出防止のための人材管理の状況（該当欄に✓チェック）

	している	しない
(1) 内部者に対する秘密保護誓約書の締結	①	②
(2) 定期的な関連教育の実施	①	②
(3) 転職禁止約定などの競業禁止の義務付け	①	②
(4) 外部者（取引先）に対する保安誓約書の作成など保護義務の明確化	①	②

60. 営業秘密管理及び技術流出防止のための物的管理の状況（該当欄に✓チェック）

	している	しない
(1) 外部者に対する出入統制	①	②
(2) アクセス権限の付与など内部者に対するアクセス管理	①	②
(3) 文書のレベル指定（秘密、対外秘など）	①	②
(4) 電子文書の管理（USB、外部メール、シャットアウトなど）	①	②
(5) 非電子文書の管理（印刷、搬出、廃棄など）	①	②

61. 国内企業の効果的な知的財産保護のための政策支援

	政府政策の必要性				
	低い	← 中間	→	高い	
(1) 産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免	①	②	③	④	⑤
(2) 海外出願関連の情報を提供	①	②	③	④	⑤
(3) 知的財産権侵害に対する強力な処罰基準の制定	①	②	③	④	⑤
(4) 知的財産権侵害に対するコンサルティング支援と共同取締り	①	②	③	④	⑤
(5) その他( )	①	②	③	④	⑤

V. 知的財産侵害及び紛争

知的財産権侵害の被害\*規模及び内容

**※知的財産権侵害の被害**：貴社の知的財産権を侵害した製品・サービスが国内・外で製造・販売されることで該当知的財産を保有する貴社の利益に直間接的な被害を受けたことを意味する。

62. 知的財産権侵害製品からの類型別被害件数(2013年基準)(なければ「0」記入後、Q74へ)

権利類型		侵害製品の販売/流通地域					
		国内	米国	中国	日本	ヨーロッパ	その他
産業 財産権	(1) 特許	件	件	件	件	件	件
	(2) 実用新案	件	件	件	件	件	件
	(3) 商標	件	件	件	件	件	件
	(4) デザイン(意匠)	件	件	件	件	件	件
新知的 財産権	(5) 半導体配置設計	件	件	件	件	件	件
	(6) 地理的表示	件	件	件	件	件	件
	(7) 営業秘密	件	件	件	件	件	件

	(8)その他	件	件	件	件	件	件
--	--------	---	---	---	---	---	---

63. (被害件数が1件以上の場合)具体的な侵害内容及び発見経路(複数回答)

NO.	(1)権利 類型(下 記の例を 参照)	(2)侵害 製品の製 造者 (下記の 例を参 照)	(3)侵害 製品の製 造地域 (下記の 例を参 照)	(4)侵害 製品の流 通地域 (下記の 例を参 照)	(5)侵害 製品の流 通類型 (下記の 例を参 照)	(6)侵害 製品の発 見経路 (下記の 例を参 照)	侵害によ る輸出被 害発生の 経験有り ※	侵害によ る輸入被 害発生の 経験有り ※※
例示	①特許権	②国内企 業	①国内	①国内④ 日本	①オンラ イン流通	③市場調 査を通じ て	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- (1) 権利類型の例：①特許権 ②実用新案権 ③商標権 ④デザイン(意匠)権  
⑤半導体配置設計権 ⑥地理的表示権 ⑦営業秘密 ⑧その他
- (2) 侵害製品の製造者の例：①海外企業(または海外企業の国内法人)  
②国内企業(または国内企業の海外法人) ③個人 ④その他
- (3) 侵害製品の製造地域の例：①国内 ②米国 ③中国 ④日本 ⑤ヨーロッパ ⑥その他
- (4) 侵害製品の販売/流通地域の例：①国内 ②米国 ③中国 ④日本 ⑤ヨーロッパ ⑥その他
- (5) 侵害製品の流通類型の例：①オンライン流通(ネットショッピング/通販など)  
②オフライン流通(代理店/市場など)
- (6) 侵害製品の発見経路の例：①国内外の営業店を通じて ②博覧会/展示会を通じて  
③市場調査やネットを通じて ④税関、警察の摘発などを通じて ⑤その他

※侵害による輸出入被害発生状況：該当する侵害発生内容が貴社の輸出入活動と関連があるかどうかを聞く質問です。侵害発生によって貴社の輸出入活動に被害が発生した場合、該当欄に✓チェックしてください。

64. 貴社の場合、知的財産権侵害の被害が発生した主な原因はどこにあるとお考えでしょうか。(複数回答)

- ①ノウハウを持つ人材移動による核心技術の流出  
②協力会社の契約違反による技術流出  
③製品の認知度向上による模倣品の流通  
④保護を受けられる法・制度の不備  
⑤DRM など技術的な保護措置などの普及支援の不備及び経済的な負担  
⑥偏頗的な法制度の適用  
⑦侵害に対する消極的な対応及び知的財産権の保護・管理不足  
⑧現在の法制度に対する情報不足  
⑨その他( )

65. 貴社が保有する知的財産権を侵害した製品が製造・販売されたことで受けた被害の規模(2013年)(該当する内容がない場合は件数に「0」と記入)

種類	被害金額の合計(範囲、億ウォン)	件	被害金額
----	------------------	---	------



(3) 中国	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	①
(4) 日本	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	①
(5) ヨーロッパ	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	①
(6) その他地域	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	①

67. 知的財産権侵害による被害が発生した時、効果的に対応するために行う活動（侵害類型別に該当する項目に優先順位によって1から3まで番号を記載）

		行政機関に 取締り及び 調査を要請	民・刑事訴訟な ど司法的な救済 手続きを申請	警告書の 送付など 独自処理	対応 しな い	該当 経験 なし
侵害 類 型	(1) 国内製造・国内販売など 国内流通段階の被害の時	順位	順位	順位	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(2) 海外製造・国内輸入販売 による被害の時	順位	順位	順位	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(3) 国内製造・海外輸出販売 による被害の時	順位	順位	順位	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(4) 海外製造・海外輸出販売 による被害の時	順位	順位	順位	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※侵害類型(4)と回答した場合、行政機関及び司法的救済申請は該当地域(国家)の行政機関及び司法機関を利用した場合に該当する。

68. (行政機関への取締り及び調査要請の経験があると答えた場合)依頼した行政機関(複数回答可能)

- ①貿易委員会      ②特許庁      ③関税庁      ④警察庁      ⑤その他(      )

69. 知的財産権侵害被害への対応費用(該当しない場合は「0」と記入)

被侵害への対応費用(紛争費用)	2013年
-----------------	-------

知的財産権侵害被害への対応費用	件数	費用合計(百万ウォン)
☞ 警告書の送付から侵害訴訟完了時までかかった費用基準(損害賠償額または和解金額を除く)		

70. (既に終結した紛争件に対して)知的財産権侵害に対応して行政的措置または司法的措置を取った場合、スタートから終結までの平均所要機関(該当しない場合「該当なし」に✓チェック)

平均所要機関						
6か月未満	6か月～1年未満	1年～1年6か月未満	1年6か月～2年	2年～3年	3年以上	該当なし
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

71. 知的財産権紛争に対応する際、法律的な諮問(審判・訴訟の際の代理を含む)における内・外部専門家の活用状況(複数回答可能)

専門家の活用状況						
内部専門家を活用している			外部専門家を活用している			法律専門家の諮問なく独自に対応
社内弁護士	社内弁理士	その他	外部弁護士	外部弁理士	その他	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

72. (対応活動を行わなかったと答えた場合)その理由(其々の対応活動(1)、(2)、(3)に対して③にチェックした場合 Q73 へ、①、②、④にチェックした場合 Q74 へ)

対応活動	対応しなかった理由
(1)行政機関に知的財産権侵害製品に対する取締り及び侵害事実に対する調査を要請	①申請手続きや活用方法が分からない ②人材と予算が不足 ③知的財産侵害への対応効果が少ない(チェック後 Q73 へ) ④必要ない





(2) 米国	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	①
(3) 中国	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	①
(4) 日本	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	①
(5) ヨーロッパ	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	①
(6) その他	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	①

75. (Q74 で権利侵害の警告を受けたり、起訴された経験がある場合)権利侵害を提起した主体

- ① 該当特許と関連のある業界に従事する、もしくは該当特許関連製品を生産する機関または個人
- ② 該当特許と関連のある業界に従事せず、また該当特許関連製品を生産していない機関(NPE)または個人
- ③ その他( \_\_\_\_\_ )

**知的財産権紛争の対応結果**

76. 知的財産権紛争に対応した結果、実際取られた措置(複数回答可能)

- ① 侵害製品の生産中止      ② 損害賠償額の支給/受取      ③ 和解金の支給/受取後の和解
- ④ ライセンスの締結      ⑤ その他( \_\_\_\_\_ )      ⑥ 該当なし(チェック後 Q80 へ)

77. (知的財産権の侵害に対応した場合)損害賠償額または和解金(2013 年基準、該当しない場合件数に「0」と記入)

種類	被害金額の合計(範囲、億ウォン)							件数	被害金額の合計(金額、億ウォン)
	1 億ウォン未満	1～5 億ウォン未満	5～10 億ウォン未満	10～15 億ウォン未満	15～20 億ウォン未満	20～30 億ウォン未満	30 億ウォン以上		
損害賠償額または和解金*	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	件	億ウォン

\***損害賠償額または和解金**：民事訴訟を通じて損害賠償額が認められたり、当事者間

の和解が成立した場合

78. 知的財産権紛争の対応結果に対する満足度

紛争対応の結果に対する満足度				
低い	←	中間	→	高い
①	②	③	④	⑤

 知的財産権紛争関連の問題及び必要な政府政策

79. 知的財産権の侵害または被侵害による紛争が発生した際の問題

	問題の程度				
	低い	←	中間	→	高い
(1) 知的財産権の法規など関連事項に対する情報不足	①	②	③	④	⑤
(2) 内部人材の専門性不足による関連知識の習得が難しい	①	②	③	④	⑤
(3) 紛争対応関連の政府支援政策の不足または関連情報の不足	①	②	③	④	⑤
(4) 紛争に対応するための法律代理人選定が難しい	①	②	③	④	⑤
(5) 紛争対応の際、過剰な時間と費用がかかる	①	②	③	④	⑤
(6) 知的財産保護のための行政的・司法的救済手続きの不備					
(7) その他( )	①	②	③	④	⑤

80. 知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策

	政府政策の必要性及び緊急度				
	低い	←	中間	→	高い
(1) 実効性のある行政的・司法的処罰措置の強化	①	②	③	④	⑤
(2) 迅速な権利救済のために国境措置対象の知的財産権範囲(特許、デザイン権)を拡大、侵害物品国内流入のシャ	①	②	③	④	⑤

ットアウト					
(3) 知的財産権の保護及び対応活動のための情報提供活動の強化	①	②	③	④	⑤
(4) 行政機関の知的財産権侵害製品の取締り権限の強化	①	②	③	④	⑤
(5) 知的財産権侵害製品などに対する通報褒賞金額の増額	①	②	③	④	⑤
(6) 知的財産権侵害対応のための訴訟などの費用支援	①	②	③	④	⑤
(7) 侵害及び知的財産権の有効性判断機関の一元化(例：特許裁判所)	①	②	③	④	⑤
(8) その他( )	①	②	③	④	⑤

アンケート調査に最後までご協力いただき、ありがとうございます。

## < 付録3 > 調査票：大学・公共研究機関



実施機関：特許庁、

貿易委員会

承認番号：第 13802 号

# 知的財産活動調査票

－ 大学、公共研究機関用 －

2014

特許庁

貿易委員会

韓国知識財産研究院

# 知的財産活動調査票(大学及び公共研究機関用)

ID 

--	--	--	--

## < 調査概要 >

本調査は韓国企業及び大学・公共(研)の知的財産活動状況を把握することで競争力強化に役立つ課題を発掘し、これを知的財産政策の樹立に反映することで企業及び大学・公共(研)の効果的な知的財産活動を支援するために特許庁、貿易委員会と韓国知識財産研究院が共同で行っております。

本調査は統計庁の承認統計として、この調査票に記載された内容は統計法第 33 条によって秘密が保護され、本調査の要約結果は今後ご回答頂いた企業及び公共研究機関のご担当の方に e-mail で送付致します。本調査にご協力いただき、ありがとうございます。

## < お問合せ >

韓国知識財産研究院 (KIIP)

(株)コリアデータネットワーク (KDN) 電話番号 : 02-2183-9159

## < 送付方法 >

調査票の送付手段はメール、FAX、郵便いずれも可能で、書類様式は韓国知識財産研究院のホームページ (<http://www.kiip.re.kr>) からダウンロードすることができます。

## < 送り先 >

135-914 ソウル市江南区駅三洞 667-14KDN ビル チェ・キュヒョック 研究員

FAX : 02-548-5144、02-512-0777 E-mail : [kdn21@kdn21.co.kr](mailto:kdn21@kdn21.co.kr)

機関名		機関所在地 (市/郡単位)	
回答者名前		部署/職位	
回答者連絡先		回答者 E-mail	

## I. 機関の一般事項及び知的財産インフラ

### 機関の研究開発規模

1. 研究開発人材\* (該当欄に数字で記入。2013 年基準)

研究開発 (R&D) 人材
---------------

全体	男性	女性
名	名	名

※ **研究開発人材**は学士号以上の学位所持者または同等以上の専門知識を備えている人で、科学技術、産業技術などの研究開発活動に従事している人材を意味し、機能職従事者、臨時職、管理職従事者は除く。

※ 「研究開発活動調査」に回答した場合は「科学技術研究開発活動調査票」の「研究開発人材」項目のうち「研究員数」を参照して研究開発人材数を記入。

## 2. 研究開発費\* (該当欄に数字で記入。2013年基準)

研究開発(R&D)費(共通)	政府からもらった研究開発費	億ウォン
	企業からもらった研究開発費	億ウォン
	自己負担の研究開発費	億ウォン

※ **研究開発費**は新しい技術、製品を開発したり、既存の知識を活用して新しい方法を探し出すために行われた調査・研究活動に支出された費用として間接費は除く。

「科学技術研究開発活動調査」に回答した場合は「科学技術研究開発活動調査票」の「研究開発費」項目を参照して記入。

## 知的財産\*担当人材

※ **知的財産**とは人間の創造的な活動の産物を総称する用語として、産業財産権(特許、実用新案など)、著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)及び権利化されていないアイデア、ノウハウなどを全て含む。

※ **産業財産権**とは産業上の利用価値を持つ発明などに関する権利として、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権を含む。

※※ **著作権**とは著作者が自分の著作物を独占的に利用したり、これを他人に許諾できる人格的、財産的権利を意味する。

※※※ **新知的財産権**とは経済・社会または文化の変化や科学技術の発展によって新しい分野で出現する知的財産(知識財産基本法第3条の2)で、伝統的な知的財産権の範疇では保護が難しいコンピュータプログラム、遺伝子組み換え動植物、半導体設計、インターネット、キャラクター産業などに関連する権利を意味する。

※**特許権**とは産業財産権の中で最も高度な技術性を持つもので、基本的に産業上の利用可能性、新規性、進歩性の3つの要件によって登録が可能。

※※**実用新案権**とは既存の物品を改良して実用性と有用性を高めた考案を出願して付与を受ける権利を意味する。

※※※**デザイン権**とは産業的物品または製品の独創的かつ装飾的な外見形状を保護するために登録を通じて許容された権利を意味し、技術とは関係なく物品の美的外見を視覚的な観点から把握できるものを意味する。

※※※※**商標権**とは生産者または商人が商標を特許庁に出願して登録することで登録商標を指定商品に独占的に使用できる権利を意味する。

3. 知的財産担当組織\*の保有状況(該当欄に✓チェック)

担当組織の保有状況		担当組織なし
一般行政組織内	R&D 企画・管理組織や産学協力団内	
①	②	③

4. 知的財産担当人材\*の数(該当欄に数字で記入)

知的財産専門担当人材※※	名	男性	名
		女性	名
その他部署業務(例:総務、人事、R&D 企画)との兼任人材	名	男性	名
		女性	名

※知的財産担当組織または人材は知的財産の戦略企画、国内外産業財産権の出願及び登録、維持管理、知的財産権の動向調査、特許侵害関連の対応及び訴訟業務、知的財産権の販売またはライセンス交渉及び技術料管理などの業務を担当する組織及び人材を意味する。

※※**知的財産専任人材**: 知的財産関連業務だけを専門的に担当する人材

5. 知的財産担当者(兼任人材を含む)の主要業務(知的財産担当人材を1名以上保有する場合該当欄に✓チェック)


人材数	ない	1~3名	3~5名	5~10名	10名以上
-----	----	------	------	-------	-------



業務内容		未満	未満	未満	
産業財産権の出願/登録/維持	①	②	③	④	⑤
知的財産関連の紛争/訴訟	①	②	③	④	⑤
ライセンスなど知的財産の活用	①	②	③	④	⑤
知的財産の評価/分析/審査	①	②	③	④	⑤
知的財産戦略の樹立	①	②	③	④	⑤
知的財産関連の教育	①	②	③	④	⑤

6. 知的財産専任人材に対する今後の採用計画(該当欄に✓チェック)

現在保有していない場合		現在保有している場合	
新規採用計画がある	採用計画はない	追加採用計画がある	追加採用計画はない
①	②	③	④

 知的財産担当人材の職務教育

7. 知的財産担当人材に対する職務教育の状況(該当欄に✓チェック)

職務教育を行っている		しない
機関が独自に実施	外部機関を通じて	
①	②	③

8. 知的財産担当人材向け職務教育の必要性(該当欄に✓チェック)

必要ない	←	普通	→	とても必要
①	②	③	④	⑤

9. 知的財産人材向け職務教育の実施を希望する場合、主に取り扱うべき教育内容(該当するものは全て✓チェック)

- ①特許制度      ②特許明細書の作成法      ③特許情報検索      ④特許紛争(訴訟)  
 ⑤特許情報の分析法(特許マップ)      ⑥特許ライセンス(技術事業化)  
 ⑦海外特許出願及び訴訟      ⑧営業秘密保護      ⑨その他(      )

10. 知的財産人材の能力を高めるため政府が最も推進を急ぐべき課題(1つだけ✓チェック)

- ①大学に特許関連教育課程及び学科の開設
- ②企業を対象とする実務中心教育課程の構成及び教材の開発
- ③企業の特許教育を担当する専門講師の育成
- ④新規知的財産人材の養成
- ⑤既存人材のための再教育プログラムの提供
- ⑥知的財産関連のコンサルティングまたは相談の提供
- ⑦その他( )

11. 知的財産担当者に対する人件費及び教育費(2013年基準)

知的財産担当者に対する人件費*	(百万ウォン)
教育費(知的財産担当者対象)**	(百万ウォン)
知的財産関連の教育費(研究開発者など従業員対象)***	(百万ウォン)

\*他業務と兼職である場合、知的財産関連業務の比重を考慮してお答えください。

\*\*知的財産担当者及び担当部署の知的財産専門能力を高めるために行われた対内外教育プログラムへの参加及び知的財産関連専門セミナーの進行など教育と関連する費用を意味する。

\*\*\*知的財産の創出、権利化、活用などに関連して企業内部の研究開発者及び従業員の基礎的な知的財産関連素養を涵養するための教育費用を意味する。

### 知的財産サービスの活用状況

※知的財産(IP)サービスとは知的財産の創出、保護、活用などを支援する専門サービスとして、情報調査・分析、技術移転・取引、翻訳、コンサルティングなどの事業

12. 国内知的財産サービスの活用状況及び分野別支出額(該当欄に✓チェック及び金額を記入)

現在の利用状況 (2013基準、該当欄 に✓チェック)		分野	説明	支出額(2013年) (ない場合0)
利用している	①	IP情報調査/ 分析	特許DB、調査分析、特 許マップの作成、動向	万ウォン

		分析など	
	技術移転/取引	技術マーケティング、特許等級評価、技術評価など	万ウォン
	IP 翻訳	明細書の翻訳、仕様書の翻訳、翻訳出版など	万ウォン
	IP コンサルティング	IP 経営、IP 戦略コンサルティング	万ウォン
	IP インフラ	IP 教育、IP システムの構築など	万ウォン
	その他	IP 法律代理業務	万ウォン
利用していない	利用していない理由(複数回答可能)		
	②	自社の保有人材で充分該当業務を行うことができる	
	③	必要性は認識しているもののどの機関を利用すればいいかわからない	
	④	知的財産サービスにかかる費用が高価である	
	⑤	知的財産サービス提供機関の品質が信頼できない	
	⑥	知的財産サービス提供機関の情報保安が信頼できない	
	⑦	その他( )	

13. 知的財産サービス提供機関別の利用比重(該当欄に数値を記入)

区分	利用比重
民間知的財産サービス専門企業(弁理士事務所を除く)	%
弁理士事務所	%
韓国特許情報院、韓国発明振興会、韓国知識財産戦略院、技術保証基金など公共機関	%
合計	100%

## ● 総合的な知的財産管理システム

14. 総合的な知的財産管理システムの構築または活用状況(該当欄に✓チェック)

- ①特許など出願/登録過程と目録などが管理されている(発明届出から出願、中間事件、登録、維持、放棄などに関連する行政手続きと特許費用、関連情報などの管理システムを保有)
- ②特許などの出願/登録過程と目録などが業績評価など人事管理、研究課題管理システム、技術移転システムと連動して総合的に管理されている。
- ③知的財産管理システムが構築されていない(→③にチェックした場合 Q16 へ)

15. (知的財産管理システムを構築または活用している場合)構築方法と所要費用(2013年基準)

構築方法	構築費用または賃借費用 (年間維持費用を含む)					
	500万 ウォン 未満	1000万 ウォン 未満	3000万 ウォン 未満	5000万 ウォン 未満	1億 ウォン 未満	1億 ウォン 以上
①機関固有の管理システムを構築	①	②	③	④	⑤	⑥
②外部の管理システムを賃借して活用	①	②	③	④	⑤	⑥

## ● (大学の場合)知的財産関連教育の状況

16. 知的財産関連講座の開設状況及び講座数

- ①開設されている(講座数\_\_\_\_\_講座)
- ②開設されていない


17. 知的財産関連講座講師における専任教員の存在有無

- ①専任教員として存在する
- ②専任教員として存在しない

## II. 特許基盤の知的財産活動

\*該当部分の調査項目は「特許に特異的な項目」に対してより明確な状況を把握する

ためのものであり、保有している産業財産権(特許権、実用新案権、商標権、デザイン権)のうち特に特許を念頭においてお答えください。

 先行特許調査\*など特許情報の活用

※ 先行特許(技術)調査とは新技術開発などのための研究開発(R&D)活動に先行して開発しようとする技術に対する先行技術または該当技術と同一もしくは類似する特許が存在するかどうかなどを調査することである。機関レベルで行う先行技術調査活動及び研究者レベルで行う先行技術調査活動を全て含む。

18. 特許(技術)情報調査の状況(該当欄に✓チェック及び数字で記入)

実施状況	
実施している(✓チェック及び数字記入後、Q20へ)	① 研究開発企画段階で全体研究開発課題のうち_____%
実施していない(✓チェック後、Q19へ)	②

19. (先行特許調査を行っていない場合)その主な理由(該当欄に✓チェックまたはその他意見の作成後、Q21へ)

- ①先行特許(技術)調査の実施による費用負担
- ②先行特許(技術)調査を実施するための専門人材の不足
- ③先行特許(技術)調査の実施に対する認識不足
- ④先行特許(技術)調査活動の実効性が不足(技術の寿命周期の短縮などで先行技術調査の実行性減少など)
- ⑤その他(\_\_\_\_\_)

20. (先行特許調査を行っている場合)実施人材(該当するものは全て✓チェック後、Q21へ)

内部人材			外部人材	
知的財産 専担人材	R&D 人材	その他(企画など)人材	弁理士/ 弁理士事務所	専門調査/ 評価機関

①	②	③	④	⑤
---	---	---	---	---

21. 機関レベルの特許(技術)情報調査支援の状況(該当するものは全て✓チェック)

- ①機関の主要研究分野に対する各国の特許情報、技術動向などを調査して特許マップとして構築、研究者に提供
- ②(研究者の要請がある場合)開発しようとする技術の動向や類似する特許が存在するかどうかを調査して研究者に提供
- ③研究者に技術動向や先行特許(技術)調査のための費用を支援
- ④特別な支援は行っていない

22. 特許(技術)情報調査の必要性(該当欄に✓チェック)

必要性				
必要ない	←	中間	→	とても必要
①	②	③	④	⑤

### 職務発明補償

※**職務発明**：従業員(法人の役員を含む)がその職務に関して発明したものが性質上使用者・法人の業務範囲に属し、その発明行為が従業員の現在または過去の職務に属する発明(特許、実用新案、デザイン)

※**職務発明補償制度**：従業員は職務発明に対して特許などを受けられる権利や特許権などを契約や勤務規定によって使用者・法人に承継させたり、専用実施権を設定した場合は正当な補償を受けられる権利を持つ制度(発明振興法)

23. 職務発明補償制度の認識度(該当欄に✓チェック)

区分	全く知らない ← → 非常に詳しい				
	①	②	③	④	⑤
(1)職務発明補償制度に対して	①	②	③	④	⑤
(2)職務発明と個人発明(職務発明以外の発明)の概念に対して	①	②	③	④	⑤
(3)職務発明に対する権利の帰属または承継に対して	①	②	③	④	⑤

(4) 補償の算定方法(金銭的・非金銭的)に対して	①	②	③	④	⑤
---------------------------	---	---	---	---	---

24. 職務発明補償規定\*の保有・活用状況(該当欄に✓チェック)

保有している(該当欄に✓チェック後 Q26 へ)		保有していない (✓チェック後、 Q25 へ)
企業独自に職務発明補償規定 を作成・活用	特許庁など関連機関が作成・ 普及した標準化された職務発 明補償規定を保有・活用	
①	②	③

※職務発明補償規定：使用者・法人が承継した従業員の職務発明に対して正当な補償を定めた契約や勤務規定

25. (職務発明補償規定を保有していない場合)その主な理由(該当欄に✓チェックまたはその他意見の作成後、Q29 へ)

- ①職務発明補償金を支給する必要がない
- ②他職員との衡平性
- ③補償規定がなくても別途のインセンティブが与えられる
- ④補償金を支給する場合、企業の負担が大きいため
- ⑤必要性は認識しているもののどのように導入すればいいかわからない
- ⑥使用者の導入意志が全くない
- ⑦その他(\_\_\_\_\_)

26. 職務発明補償の実施状況と補償金の水準(該当欄に✓チェック後、Q27 へ)

※出願補償：出願が完了した職務発明を対象に支給する補償  
 ※※登録補償：登録された職務発明を対象に支給する補償  
 ※※※実施補償：職務発明をライセンス契約などを通じて企業などに移転し、技術料収入が発生した場合に支給する補償  
 ※※※※処分補償：職務発明を売却などを通じて処分して収入が発生した場合に支給する補償

区分	実施状況				金銭的補償を実施する場合、職務発明補償金の水準	
	金銭的補償	非金銭的補償(昇進、成果評価反映)	両方補償	実施しない		
発明提案(発明届出)補償	①	②	③	④	万ウォン	
出願留保補償	①	②	③	④	万ウォン	
国内特許出願補償 <sup>※</sup>	①	②	③	④	万ウォン	
国内特許登録補償 <sup>※※</sup>	①	②	③	④	万ウォン	
海外特許出願補償	①	②	③	④	万ウォン	
海外特許登録補償	①	②	③	④	万ウォン	
その他産業財産権の国内登録補償	①	②	③	④	万ウォン	
その他産業財産権の海外登録補償	①	②	③	④	万ウォン	
					一定比率支給の場合	固定金額支給の場合
自社実施補償 <sup>※※※</sup>	①	②	③	④	収入金の平均(%)	万ウォン
他社実施補償 <sup>※※※</sup>	①	②	③	④	収入金の平均(%)	万ウォン
処分補償 <sup>※※※※</sup>	①	②	③	④	収入金の平均(%)	万ウォン

27. 職務発明に対する非金銭的な補償(業績評価など)(該当欄に✓チェック)

	業績評価などに反映していない	(SCI 級)論文提出の時、業績評価への反映 =100 とした場合				
		30 以下	50 以下	70 以下	100 以下	100 超過
特許など産業財産権の国内出願	①	①	②	③	④	⑤



特許など産業財産権の海外出願	①	②	③	④	⑤
特許など産業財産権の国内登録	①	②	③	④	⑤
特許など産業財産権の海外登録	①	②	③	④	⑤
産業財産権の移転や売却を通じた技術料収入の発生	①	②	③	④	⑤

28. 支給された職務発明\*の補償費用（2013年基準、該当欄に数字で記入）


補償の種類	補償費用
(1) 発明届出補償/出願/登録補償	(百万ウォン)
(2) 実施/処分補償	(百万ウォン)

※職務発明補償費用は貴機関が定めた補償制度に基づき発明者と創作者などに支払った補償金である(実施補償、処分補償など)。

29. 職務発明補償と関連するあらゆる制度の効果(該当欄に✓チェック)

※企業レベルや国家レベルで現在の実施状況とは関係なくお答えください。

関連制度		効果ない ← →とても効果的				
		①	②	③	④	⑤
職務発明に対する補償実施または補償水準の拡大 (機関レベル)	発明の品質及び件数の増加	①	②	③	④	⑤
	技術流出の防止	①	②	③	④	⑤
職務発明補償金に対する 所得税の非課税 (政府レベル)	発明の品質及び件数の増加	①	②	③	④	⑤
	技術流出の防止	①	②	③	④	⑤

 技術取引機関、技術マーケティング会社との協力

30. 最近3年間(2011~2013年)技術取引、技術マーケティングのために国内外企業、技術取引機関などに業務を依頼したり、業務協約を締結しているかどうかに関して(該当欄に✓チェック)

	業務協約を 締結	業務を依頼	依頼しない
(1)国内企業または企業研究所			
(2)地域技術移転センター、技術取引所 など国内公共機関			
(3)国内民間技術仲介、技術マーケティング会社			
(4)海外機関または民間会社			

31. (技術取引機関などに業務を依頼した場合)主な費用支給方法(該当欄に✓チェック)

- ①調査/マーケティング費用など活動費(前金)+成功報酬(定額)  
 ②調査/マーケティング費用など活動費(前金)+成功報酬(技術移転収益などによる定率)  
 ③成功報酬(定額) ④成功報酬(技術移転収益などによる定率) ⑤その他

32. 技術取引システムの活用度(該当欄に✓チェック)

	活用し ない	活用度				
		低い	← 中間 →	高い		
(1)IP-mart(インターネット特許技術広場)、NTB など国内オンライン取引システム/DB	①	②	③	④	⑤	
(2)特許技術移転説明会など国内オフライン取引システム	①	②	③	④	⑤	
(3)yet2.comなど海外オンライン取引システム/DB	①	②	③	④	⑤	
(4)海外オフライン取引システム	①	②	③	④	⑤	

### Ⅲ. 知的財産の創出及び活用活動

#### 知的財産統計など基礎統計情報の活用

33. 知的財産統計など基礎統計情報の活用(該当欄に✓チェック及び直接記入)

①活用している(主に活用する統計指標※ : \_\_\_\_\_)

②活用していない

※知的財産統計年報などで提示する年度別出願件数及び登録件数、産業部門別出願件数、国家別審判請求件数など主に参考として活用する知的財産関連の統計指標を意味する。

34. より頻繁に公表してほしい統計指標 ( \_\_\_\_\_ )

35. 知的財産情報システムの活用度(該当欄に✓チェック)

	活用 しな い	活用度					(活用する場合) 主に活用する 情報システム
		低い	←	中間	→	高い	
KIPRIS など政府提供の 情報システム	①	①	②	③	④	⑤	( )
WIPS、DELPION など民 間提供の情報システム	①	①	②	③	④	⑤	( )
その他情報システム	①	①	②	③	④	⑤	( )

### 知的財産創出のための研究開発(R&D)活動及び今後の戦略

36. 優秀な知的財産を創出するため、現在機関レベルで行っている活動(該当するものは全て✓チェック)

- ①機関の特性に適した研究開発の発掘及び機関独自の研究開発の拡大
- ②産学研協力を通じた共同/委託研究開発の拡大
- ③研究開発企画の際に市場ニーズが反映できる制度的な体系の構築
- ④中大型、重要研究開発課題から優秀特許を創り出すための研究開発企画の強化

37. (現在の実施状況とは関係なく)優秀な知的財産を創り出すために必要と考える活動や戦略(重要度によって2つ以内で✓チェック)

- ①機関の特性に適した研究開発の発掘及び機関独自の研究開発の拡大
- ②産学研協力を通じた共同/委託研究開発の拡大

③ 研究開発企画の際に市場ニーズが反映できる制度的な体系の構築

④ 中大型、重要研究開発課題から優秀特許を創り出すための研究開発企画の強化

### 知的財産活用の方向と戦略

38. 保有している知的財産権※に対する実査\*\*（評価）の実施状況（該当欄に✓チェック及び数字で記入）

実施状況	
実施している（✓チェック及び数字記入後、Q40へ）	① 保有している全体知的財産権のうち _____ %
実施しない（✓チェック後、Q39へ）	②

※**知的財産権**とは産業財産権（特許、実用新案など）の他に著作権、新知的財産権（営業秘密、半導体配置設計など）を総称。

※※**保有知的財産権に対する実査**とは特許などの維持/放棄の決定、事業化有望技術及び移転対象技術などを発掘するために保有している知的財産権の価値を把握することを意味する。

39. （実査を行っていない場合）その主な理由（該当欄に✓チェックまたはその他意見の作成後、Q41へ）

- ① 知的財産権実査の実施による費用負担
- ② 知的財産権実査を実施するための専門人材の不足
- ③ 知的財産権実査の実施に対する認識不足
- ④ 知的財産権実査活動を行うには累積知的財産権の数が少ない関係で行っていない
- ⑤ 実査（評価）活動の実効性が不足（実査結果の活用度が落ちる）
- ⑤ その他（\_\_\_\_\_）


40. （実査を実施している場合）実施人材（該当する全てのものに✓チェック後、Q41へ）

内部人材	外部人材
------	------

知的財産 専担人材	R&D 人材	その他(知的財産実査 委員会など)人材	弁理士/ 弁理士事務所	専門調査 /評価機関
①	②	③	④	⑤

41. 実査実施の必要性(該当欄に✓チェック)

必要性				
必要ない	←	中間	→	とても必要
①	②	③	④	⑤

 知的財産\*の売却または移転状況

※知的財産は産業財産権(特許、実用新案、商標、デザイン)、著作権、新知的財産権(営業秘密、半導体配置設計など)、ノウハウなどを全て含む

42. 知的財産の売却または移転実績(該当欄に数字で記入、2013年基準)

		国内に売却または移転	海外に売却または移転
企業などに売却または移転した知的財産の件数		件 (このうち特許は 件)	件 (このうち特許は 件)
→	(共同または委託研究開発契約など)研究開発契約に <u>技術移転義務条項(強制実施)が含まれ、移転または売却された知的財産の件数</u>	件 (このうち特許は 件)	件 (このうち特許は 件)
	権利行使に <u>制約のない</u> 移転(licensing-out)件数	件 (このうち特許は 件)	件 (このうち特許は 件)
	独自の保有知的財産の売却(sale)件数	件 (このうち特許は 件)	件 (このうち特許は 件)

43. 知的財産の売却または移転の際、最も大きな問題(該当欄に✓チェック)

- ①取引機関の能力不足
- ②需要先-供給先の発掘が難しい
- ③技術料の算定が難しい(信頼できる評価機関の不足)
- ④保安上の問題で取引の推進が難しい

⑤その他( )

44. 知的財産の有償実施許与または売買契約の成果(該当欄に数字で記入、2013年基準)

		収入	
		産業財産権の実施許与/売却	(百万ウォン)
		ノウハウだけの実施許与/売却	(百万ウォン)
→	国内	企業から	%
		その他法人から	%
→	海外	企業から	%
		その他法人から	%

45. 保有している登録産業財産権の活用状況(回答時点基準で該当欄に数字記入)

	特許権*	実用新案権	デザイン権*	商標権*
権利保有件数** (A+B)	件	件	件	件
→ 活用件数(A)	件	件	件	件
外部の他機関に移転	件	件	件	件
→ 実験室創業、研究員創業などに活用	件	件	件	件
現物出資	件	件	件	件
未活用件数(B)	(登録5年未満)	(登録5年未満)		
	件	件		
→ 他機関に移転可能**	件	件		
	(登録5年未満)	(登録5年未満)		
	件	件		

\*特許権、デザイン権、商標権は「登録された」特許権、デザイン権、商標権を対象

とする。

※現在(回答時点)を基準に登録され(取消、無効、放棄などで権利が消滅されず)権利が生きている総件数を記入する。

※※他機関に移転可能: ライセンス契約などを通じて移転することに問題がない産業財産権で、事業化可能性や経済的な価値が著しく落ちるため他機関への移転が不可能と判断される産業財産権は除く。

46. 保有している出願及び登録産業財産権を活用した R&D 実施及び認証獲得の状況 (該当欄に全て✓チェック、2013年または会計年度基準)

※産業財産権は各種 R&D 事業及び主要認証を獲得する上で基盤根拠になり得るため、本質問では貴機関が国家及び民間 R&D 事業を受注する際(提案書の作成など)、各種認証獲得のための申請の際に出願及び登録産業財産権を活用した事例を全て含む。

※NET(New Excellent Technology) 認証とは技術標準院及び韓国産業技術振興協会が運営主体であり、新技術を早期に発掘して優秀性を認証することで、新技術の商用化及び取引を促進するとともに初期市場進出基盤作りを目的として設立された認証制度

※NEP(New Excellent Product) 認証とは技術標準院が運営主体であり、国内で初めて開発された技術またはこれに準ずる代替技術を適用した製品を認証することで製品の初期販路の開拓を支援し、技術開発を促進することを目的に設立された制度

※※世界一流商品認証とは産業資源通商部が運営主体であり、大韓民国国籍企業が生産する製品として一定の条件を満たせる商品のうち、産業資源通商部長官が「現在世界一流商品」または「次世代世界一流商品」として選定した商品を意味する。


(1) 産業財産権 を活用した R&D 受注の状況	R&D 受注のために産業財産権を活用した経験がある				活用経験無し
	政府 R&D に活用		民間 R&D に活用		
	①		②		③
(2) 産業財産権 を活用した主 要認証獲得の 状況	主要認証獲得のために産業財産権を活用した経験がある				活用経験無し
	NET 認証 獲得	NEP 認証 獲得	世界一流商 品認証獲得	その他 認証獲得	
	①	②	③	④ ( )	⑤

47. 産業財産権を活用しない主な理由(該当欄に✓チェックまたはその他意見の作成)

- ①(自社実施、他社実施)活用するためには該当産業財産権の他に後続研究開発を通じた関連産業財産権の獲得が必要であるが、該当後続活動が不十分
- ②(他社実施、技術移転)産業財産権に対する需要機関の発掘が難しい
- ③(他社実施、技術移転)産業財産権に対する需要機関との交渉が難しい
- ④既存産業財産権との利用・抵触関係によって紛争の恐れがあるため、活用不可
- ⑤その他(\_\_\_\_\_)

48. 企業などに移転されたり、研究員創業などに活用している産業財産権のうち、これを通じて売上(技術料収入)が発生した権利の比率(回答時点を基準に該当欄に数字で記入)

	特許権	実用新案権	デザイン権	商標権
外部の他機関に移転または実験室創業、研究員創業、現物出資などに活用されている権利の数(Q45の活用件数(A)と同一)	件	件	件	件
→売上(技術料収入)が発生した権利の数	件	件	件	件

 政府の政策支援及び必要性

49. 国内大学及び公共研究機関の効果的な知的財産創出を支援するための政策支援

	政府政策の必要性				
	低い	←	中間	→	高い
(1)個別機関が職務発明補償制度を導入したり、または補償水準が拡大できるように支援(例:特許などの出願/登録による金銭的、非金銭的な補償に関する規定の整備及び広報など)	①	②	③	④	⑤
(2)特許情報活用拡散事業の拡大などを通じて深みのある先行特許(技術)調査と特許情報の活用を支援	①	②	③	④	⑤
(3)専門家の派遣、知財権コンサルティング事業の拡大などを通じて大学と公共研究機関の知的財産創	①	②	③	④	⑤



出活動を支援					
(4)多様な技術分野に対する特許マップの構築支援	①	②	③	④	⑤
(5)研究者などを対象とした知的財産権関連教育の支援(例:教育プログラムの開発及び普及、教育関連費用の支援など)	①	②	③	④	⑤
(6)その他( )	①	②	③	④	⑤

50. 国内大学及び公共研究機関の効果的な知的財産活用のための政策支援

	政府政策の必要性				
	低い	← 中間 →			高い
(1)保有特許技術に対する価値評価の支援	①	②	③	④	⑤
(2)新技術の事業化に向けた研究所企業/実験室創業の支援	①	②	③	④	⑤
(3)特許技術の取引、流通システムの改善	①	②	③	④	⑤
(4)技術移転関連のマーケティング及びコンサルティング支援	①	②	③	④	⑤
(5)優秀技術の輸出支援	①	②	③	④	⑤
(6)その他( )	①	②	③	④	⑤

#### IV. 知的財産の保護活動

##### ● 知的財産保護の方向と戦略

51. 産業財産権(特許権、実用新案権、デザイン権、商標権)の出願などに先行して社内予備評価\*の実施状況(該当欄に✓チェック及び数字で記入)

実施状況	
実施している(✓チェック及び数字記入後、Q53へ)	① 全体届出られた発明のうち _____ %
実施していない(✓チェック後、Q52へ)	②

※「予備評価」とは提出された発明届出書に対して職務発明委員会などを通じて発明の評価、承継の可否、出願の可否、審査請求の可否などを決定することを意味する。

52. (予備評価を行っていない場合)その主な理由(該当欄に✓チェックまたはその他意見の作成後、Q54へ)

- ①予備評価の実施による費用負担
- ②予備評価を実施するための専門人材の不足
- ③予備評価の実施に対する認識不足
- ④予備評価活動の実効性が不足(予備評価のスクリーニング機能などが満足に働かない)
- ⑤その他(\_\_\_\_\_)

53. (予備評価を実施している場合)遂行人材(該当するもの全てに✓チェック後、Q54へ)

内部人材			外部人材	
知的財産 専担人材	R&D 人材	その他(審議委 員会など)人材	弁理士/ 弁理士事務所	専門調査/ 評価機関
①	②	③	④	⑤

54. 予備評価実施の必要性(該当欄に✓チェック)

必要性				
必要ない	←	中間	→	とても必要
①	②	③	④	⑤

55. 研究開発活動の成果の専有(模倣業者などからの保護または独占的に活用)するために活用する戦略(該当欄に✓チェック)

	活用 しない	活用度				
		低い	← 中間 →	高い		
(1)特許など産業財産権の出願/登録	①	②	③	④	⑤	

(2)営業秘密及びノウハウとして維持	①	②	③	④	⑤
(3)(事業化しようとする)企業などと排他的な契約を締結	①	②	③	④	⑤

56. 発明届出(Invention disclosure)件数対比特許など産業財産権の出願比率 (2013年基準)

発明届出(Invention disclosure)の件数	件
(経済性、技術性不足などの理由で)出願を留保または放棄する	件
(営業秘密として維持など)非公式的な権利保護手続きを進行	件
産業財産権の出願など公式的な権利保護手続きを進行	件

### 知的財産の管理及び保護に関する認識度

57. 現在国内の知的財産保護水準<sup>\*</sup>に対する意見(該当欄に✓チェック)

大幅な 弱化が必要	漸進的な 弱化が必要	現在の水準が 適正	漸進的な 強化が必要	大幅な 強化が必要
①	②	③	④	⑤

<sup>\*</sup>知的財産保護水準は特許制度のように知的財産に権利を付与するシステムの効率性と知的財産権が他人によって侵害を受けた時に対抗できる行政的、司法的措置が如何に整えられているのかを意味する。

58. 産業財産権の海外出願/登録の実績(該当欄に数字で記入)

<sup>\*</sup>同じ産業財産権を複数の国家に個別に出願または登録した場合にはこれを全て合算してご記入ください。例えば、A という特許を米国、日本、ドイツに出願した場合、出願件数は1ではなく3でご記入ください。

<sup>\*\*</sup>但し、PCT 出願の場合は出願書に記載されている指定国の数に関係なく、1件としてご記入ください。

	特許権の	デザイン権の	商標権の
--	------	--------	------

		海外出願/登録	海外出願/登録	海外出願/登録	
2013年 実績	(個別国家)出願件数※	(件)	(件)	(件)	
	→	米国など北米地域	(件)	(件)	(件)
		日本などアジア地域	(件)	(件)	(件)
		ヨーロッパ(EU)	(件)	(件)	(件)
		その他の地域	(件)	(件)	(件)
PCT出願※※	(件)				
登録件数※	(件)	(件)	(件)		
2013年 実績	→	米国など北米地域	(件)	(件)	(件)
		日本などアジア地域	(件)	(件)	(件)
		ヨーロッパ(EU)	(件)	(件)	(件)
		その他の地域	(件)	(件)	(件)

### ● 産業財産権出願の今後の計画

59. 2014年産業財産権の予想国内出願件数(該当欄に数字で記入及び✓チェック)

		国内特許	国内実用新案	国内デザイン	国内商標
2014年	出願/予想出願件数	(件)	(件)	(件)	(件)
2015年以後	縮小	①	①	①	①
	維持	②	②	②	②
	拡大	③	③	③	③

60. 産業財産権の国内出願の増減に影響を及ぼす要因(該当欄に✓チェック)

主要産業財産権の国内出願の増減に影響を及ぼす要因		重要度				
		低い ← 中間 → 高い				
機関内部的な 要因	① 研究開発投資または予算の増減による研究成果の変化	①	②	③	④	⑤
	② 機関の産業財産権戦略の変化(量または品質中心の知的財産出願戦略、維持費用対比収益性の	①	②	③	④	⑤

外部環 境的な 要因	変化など)					
	③産業財産権に対する成果評価比重の変化または評価方向の変化(論文などその他成果対比産業財産権実績評価比重の拡大または縮小、量的成果評価の止揚及び質的成果評価の指向など)	①	②	③	④	⑤
	④市場及び技術競争環境の変化(市場の拡大または縮小、新技術または新市場の出現など)	①	②	③	④	⑤
	⑤国内及び世界景気の変動(国内総生産の増減、物価及び為替の変化、世界金融危機など)	①	②	③	④	⑤
	⑥産業財産権出願環境の改善及び支援制度の強化(出願手数料の減免、手続きの簡素化、産業財産権創出支援制度など)	①	②	③	④	⑤

61. 出願・審査・維持費用(□2013年または□会計年度基準)

	国内出願	海外出願 (PCT出願を含む)
出願・審査費用*	(百万ウォン)	(百万ウォン)
→ 特許/実用新案権の出願・審査費用	%	%
維持費用**	(百万ウォン)	(百万ウォン)
→ 特許/実用新案権の維持費用	%	%

\*出願・審査費用は産業財産権の出願手数料、審査請求料、弁理士費用、決定系審判(特許出願に対する拒絶決定など審査官の処分に不服して請求する審判)にかかった費用などを含めた金額である。

\*\*維持費用は産業財産権の登録と権利維持にかかる金額であり、登録料と維持年金を含めた金額である。

62. 国内大学及び公共研究機関の効果的な知的財産管理及び保護を支援するための政策支援

	政府政策の必要性
--	----------

	低い ← 中間 → 高い				
	①	②	③	④	⑤
(1) 産業財産権の出願と登録にかかる費用の減免	①	②	③	④	⑤
(2) 海外出願関連情報の提供	①	②	③	④	⑤
(3) 企業などとの共同/委託研究契約の際、(発明所有権、実施権許与に対する決定権利、技術事業化の収益配分における)不平等契約を防止するためガイドラインの制定/広報	①	②	③	④	⑤
(4) 出願前または出願後に知的財産の評価費用を支援	①	②	③	④	⑤
(5) その他( )	①	②	③	④	⑤

## V. 知的財産侵害及び紛争

### 知的財産権侵害の被害\*規模及び内容

**※知的財産権侵害の被害**：貴社の知的財産権を侵害した製品・サービスが国内外で製造・販売されることで該当知的財産を保有する貴社の利益に直間接的な被害を受けたことを意味する。

63. 知的財産権侵害製品からの類型別被害件数(2013年基準)(なければ「0」記入後 Q74へ)

権利類型		侵害製品の販売/流通地域					
		国内	米国	中国	日本	ヨーロッパ	その他
産業 財産権	(1) 特許	件	件	件	件	件	件
	(2) 実用新案	件	件	件	件	件	件
	(3) 商標	件	件	件	件	件	件
	(4) デザイン(意匠)	件	件	件	件	件	件
新知的 財産権	(5) 半導体配置設計	件	件	件	件	件	件
	(6) 地理的表示	件	件	件	件	件	件
	(7) 営業秘密	件	件	件	件	件	件
	(8) その他	件	件	件	件	件	件

64. (被害件数が1件以上の場合)具体的な侵害内容及び発見経路(複数回答)

- (1)権利類型の例：①特許権 ②実用新案権 ③商標権 ④デザイン(意匠)権  
 ⑤半導体配置設計権 ⑥地理的表示権 ⑦営業秘密 ⑧その他
- (2)侵害製品の製造者の例：①海外企業(または海外企業の国内法人)  
 ②国内企業(または国内企業の海外法人) ③個人 ④その他
- (3)侵害製品の製造地域の例：①国内 ②米国 ③中国 ④日本 ⑤ヨーロッパ ⑥その他
- (4)侵害製品の販売/流通地域の例：①国内 ②米国 ③中国 ④日本 ⑤ヨーロッパ ⑥その他
- (5)侵害製品の流通類型の例：①オンライン流通(ネット/ホームショッピングなど)  
 ②オフライン流通(代理店/市場など)
- (6)侵害製品の発見経路の例：①国内外営業店を通じて ②博覧会/展示会を通じて  
 ③市場調査やネットを通じて ④税関、警察の摘発などを通じて ⑤その他

NO.	(1)権利類型(下記の例を参照)	(2)侵害製品の製造者(下記の例を参照)	(3)侵害製品の製造地域(下記の例を参照)	(4)侵害製品の流通地域(下記の例を参照)	(5)侵害製品の流通類型(下記の例を参照)	(6)侵害製品の発見経路(下記の例を参照)
例示	①特許権	②国内企業	①国内	①国内④日本	①オンライン流通	③市場調査を通じて
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

65. 貴機関の場合、知的財産権侵害の被害が発生した主な原因はどこにあるとお考えでしょうか。(複数回答)

- ①ノウハウを持つ人材の移動による核心技術の流出
- ②協力会社の契約違反による技術流出
- ③製品の認知度向上による模倣品の流通
- ④保護を受けられる法・制度の不備
- ⑤DRM など技術的な保護措置の普及支援不足及び経済的な負担
- ⑥偏頗的な法制度の適用
- ⑦侵害に対する消極的な対応及び知的財産権の保護・管理不足
- ⑧現在の法制度に対する情報不足
- ⑨その他( )

66. 貴機関が保有する知的財産権を侵害した製品が製造・販売されることで受けた被害規模(2013年)(該当しない場合は件数に「0」と記入)

種類	被害金額の合計(範囲、億ウォン)							件数	被害金額の合計(金額、億ウォン)
	1億ウォン未満	1～5億ウォン未満	5～10億ウォン未満	10～15億ウォン未満	15～20億ウォン未満	20～30億ウォン未満	30億ウォン以上		
実現被害金額*	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	件	億ウォン

\*実現被害金額：知的財産権侵害製品が市場に流通したことで技術料の減少などのような実質的な被害が発生した場合

### 知的財産権侵害に対する事後対応

67. 知的財産権被侵害に対する対応状況(2013年基準、ない場合は「ない」と記入)(貴機関の知的財産が侵害を受けたことを認知した時期に関係なく、貴機関が2013年に知的財産権侵害の被害を解決するために取った対応活動(警告書の送付、訴訟、ライセンス、仲裁など)状況に対してご記入ください。)



対応活動 侵害 発生地域	警告書の送付			行政機関に 取締りまたは調査要請			侵害者との交 渉を通じて解 決を図る(ラ イセンス、補 償など)			調停、仲裁 を図る(調停 委員会など)			民・刑事上の 司法的救済手 続きを申請			ない
	国内 企業	海外 企業	個人	国内 企業	海外 企業	個人	国内 企業	海外 企業	個人	国内 企業	海外 企業	個人	国内 企業	海外 企業	個人	
(1)国内	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	
(2)米国	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	
(3)中国	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	
(4)日本	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	
(5)ヨーロッパ	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	
(6)その他 地域	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	

68. 行政機関への取締り及び調査要請の経験がある場合、依頼した行政機関(複数回答可能)

①貿易委員会 ②特許庁 ③関税庁 ④警察庁 ⑤その他( )

69. 知的財産権侵害被害への対応費用(該当しない場合は「0」と記入)

被侵害への対応費用(紛争費用)	2013年	
知的財産権侵害被害への対応費用	件数	費用合計(百万ウォン)
☞ 警告書の送付から侵害訴訟完了時までかかった費用基準(損害賠償額または和解金額を除く)		

70. (既に終結した紛争件に対して)知的財産権侵害に対応して行政的措置または司法的措置を取った場合、スタートから終結までかかった平均所要機関(該当しない場合「該当なし」に✓チェック)

平均所要期間						
6か月未満	6か月～ 1年未満	1年～1年6 か月未満	1年6か月 ～2年	2年～ 3年	3年以上	該当なし
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

71. 知的財産権紛争に対応する際、法律的な諮問(審判・訴訟の際の代理を含む)における内・外部専門家の活用状況(複数回答可能)

専門家の活用状況						
内部専門家を活用している			外部専門家を活用している			法律専門 家の諮問 なく独自 に対応
社内弁護士	社内弁理士	その他	外部弁護士	外部弁理士	その他	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

72. (対応活動を行わなかったと答えた場合)その理由(其々の対応活動(1)、(2)、(3)に対して③にチェックした場合 Q73 へ、①、②、④にチェックした場合 Q74 へ)

対応活動	対応しなかった理由
(1) 行政機関に知的財産権侵害製品に対する取締り及び侵害事実に対する調査を要請	①申請手続きや活用方法が分からない ②人材と予算が不足 ③知的財産侵害への対応効果が少ない(チェック後 Q73 へ) ④必要ない
(2) 告訴・告発、仮処分、民・刑事訴訟など司法的救済手続きを申請	①申請手続きや活用方法が分からない ②人材と予算が不足 ③知的財産侵害への対応効果が少ない(チェック後 Q73 へ) ④必要ない
(3) 侵害企業に警告または示談を図るなど独自に対応	①独自の対応方法が分からず、対応しない ②人材と予算が不足 ③知的財産侵害への対応効果が少ない(チェ




75. (Q74 で権利侵害の警告を受けたり、起訴された経験がある場合)権利侵害を提起した主体

①該当特許と関連のある業界に従事する、もしくは該当特許関連製品を生産する機関または個人

②該当特許と関連のある業界に従事せず、また該当特許関連製品を生産していない機関(NPE)または個人

③その他(\_\_\_\_\_)

 知的財産権紛争の対応結果

76. 知的財産権紛争に対応した結果、実際取られた措置(複数回答可能)

①侵害製品の生産中止      ②損害賠償額の支給/受取      ③和解金の支給/受取後の和解

④ライセンスの締結      ⑤その他(\_\_\_\_\_)      ⑥該当なし(チェック後 Q80 へ)

77. (知的財産権の侵害に対応した場合)損害賠償額または和解金(2013 年基準、該当しない場合件数に「0」と記入)

種類	被害金額の合計(範囲、億ウォン)							件数	被害金額の合計(金額、億ウォン)
	1億ウォン未満	1~5億ウォン未満	5~10億ウォン未満	10~15億ウォン未満	15~20億ウォン未満	20~30億ウォン未満	30億ウォン以上		
損害賠償額または和解金*	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	件	億ウォン

\***損害賠償額または和解金**：民事訴訟を通じて損害賠償額が認められたり、当事者間の和解が成立した場合

78. 知的財産権紛争の対応結果に対する満足度

紛争対応の結果に対する満足度				
低い	←	中間	→	高い
①	②	③	④	⑤

 知的財産権紛争関連の問題及び必要な政府政策

79. 知的財産権の侵害または被侵害による紛争が発生した際の問題

	問題の程度				
	低い	← 中間	→	高い	
(1) 知的財産権の法規など関連事項に対する情報不足	①	②	③	④	⑤
(2) 内部人材の専門性不足による関連知識の習得が難しい	①	②	③	④	⑤
(3) 紛争対応関連の政府支援政策の不足または関連情報の不足	①	②	③	④	⑤
(4) 紛争に対応するための法律代理人選定が難しい	①	②	③	④	⑤
(5) 紛争対応の際、過剰な時間と費用がかかる	①	②	③	④	⑤
(6) 知的財産保護のための行政的・司法的救済手続きの不備					
(7) その他( )	①	②	③	④	⑤

80. 知的財産権侵害に対応するために必要な政府政策

	政府政策の必要性及び緊急度				
	低い	← 中間	→	高い	
(1) 実効性のある行政的・司法的処罰措置の強化	①	②	③	④	⑤
(2) 迅速な権利救済のために国境措置対象の知的財産権範囲(特許、デザイン権)を拡大、侵害物品国内流入のシャットアウト	①	②	③	④	⑤
(3) 知的財産権の保護及び対応活動のための情報提供活動の強化	①	②	③	④	⑤
(4) 行政機関の知的財産権侵害製品の取締り権限の強化	①	②	③	④	⑤
(5) 知的財産権侵害製品などに対する通報褒賞金額の増額	①	②	③	④	⑤
(6) 知的財産権侵害対応のための訴訟などの費用支援	①	②	③	④	⑤
(7) 侵害及び知的財産権の有効性判断機関の一元化(例:	①	②	③	④	⑤

特許裁判所)					
(8)その他( )	①	②	③	④	⑤

アンケート調査に最後までご協力いただき、ありがとうございます。

2014

知的財産活動

実態調査

報告書

---

発行	特許庁・貿易委員会
調査機関	韓国知的財産研究院
発行日	2014 年
住所	大田市西区庁舎路 189(特許庁) 042)481-8238 世宗市ハンヌリ大路 402(貿易委員会) 044)203-5881
印刷	キョンソン文化社 ソウル市永登浦区国会大路 66 キル-11 チョンフェビル 1/5 階 電話：02)786-2999(代表) FAX：02)782-1391

---